| (51) Int.Cl. ⁶ | 識別記号 | | FΙ | | | | |
|---------------------------|----------------|------|-------|----------|----|-----------|--------|
| C 0 7 D 277/30 | C 0 7 D 277/30 | | | | | | |
| A 6 1 K 31/425 | ABE | • | A 6 1 | K 31/425 | | ABE | |
| | ABF | | | | | ABF | |
| 31/44 | AEM | | | 31/44 | | AEM | |
| 31/505 | AED | | | 31/505 | | AED | |
| • | | 審查請求 | 未請求 | 蘭求項の数14 | OL | (全 121 頁) | 最終頁に続く |

(21)出願番号 特願平9-286340 (22)出顧日 平成9年(1997)10月20日

(31) 優先権主張番号 特願平8-278347

(32)優先日 平8 (1996)10月21日

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000002831

第一製薬株式会社

東京都中央区日本橋3丁目14番10号

(72) 発明者 中山 敦

東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第

一製薬株式会社東京研究開発センター内

(72)発明者 武田 聡之

東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第

一製薬株式会社東京研究開発センター内

(72)発明者 町永 信雄

東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第

一製薬株式会社東京研究開発センター内

(74)代理人 弁理士 今村 正純 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 エチニルチアゾール誘導体

(57)【要約】

【課題】 ロイコトリエン拮抗作用と肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用とを併せ持ち、アレルギー性疾患の治療及び/又は予防薬の有効成分として有用な化合物を提供する。

【解決手段】 式(1) $[R^1 \, \text{Z} \, \text{UR}^2 \, \text{Ut} \, \text{太素原子、} \cap \text{Ut} \, \text{U$

【化1】

$$\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{1} \\
\mathbb{R}^{2}
\end{array}$$

$$\mathbb{C} \equiv \mathbb{C} - \mathbb{A} - (\mathbb{G}^{1})_{m} - (\mathbb{G}^{2})_{n} - \mathbb{Q}$$
(1)

【特許請求の範囲】 【請求項1】 一般式(1) 【化1】

「式中、 R^1 及び R^2 はそれぞれ独立して水素原子、ハ

ロゲン原子、置換基を有することもあるアルキル基、置 換基を有することもあるシクロアルキル基、またはR¹ とR² が一緒になって形成する環を意味し;Aは置換基 を有することもあるフェニル基、置換基を有することも あるピリジル基、置換基を有することもあるフリル基、 置換基を有することもあるチエニル基、置換基を有する こともあるベンゾフラニル基、置換基を有することもあ るベンソ [b] チエニル基、置換基を有することもある ベンゾオキサゾリル基、置換基を有することもあるベン ゾチアゾリル基、置換基を有することもあるピリド [1. 2-a] ピリミジニル基、置換基を有することも あるキナゾリニル基、置換基を有することもあるベンゾ トリアジニル基、または置換基を有することもある2H ークロメニル基を意味し; G1 は酸素原子、カルボニル 基、エチニル基、基-NR³ CO-、基-NR⁴ -、基 -NR⁵ SO₂ -、基-SO₂ NR⁶ -、基-CONR ⁷ -、基-C (=CHR⁸) -、または、基-CR⁹ = CR¹⁰- (式中、R³、R⁴、R⁵、R⁶、及びR 7 は、水素原子、水酸基、または置換基を有することも あるアルキル基を意味し、R⁸ はシアノ基、カルボキシ ル基、または置換基を有することもあるアルコキシカル ボニル基を意味し、R⁹ 及びR¹⁰は、それぞれ独立し て、水素原子、ハロゲン原子、置換基を有することもあ るアルキル基、置換基を有することもあるシクロアルキ ル基、置換基を有することもあるアリール基、またはR 9 及びR¹⁰が一緒になって形成する環を意味する。)を 意味し; G² は置換基を有することもあるフェニル基、 置換基を有することもあるピリジル基、置換基を有する こともあるチアソリル基、置換基を有することもあるイ ソオキサゾリル基、置換基を有することもあるチエニル 基、置換基を有することもあるピリミジニル基、基-C $HR^{11}-CHR^{12}-$ 、または基- $CR^{13}=CR^{14}-$ (C $R^{15} = CR^{16}$) y - (ここで、式中、 R^{11} と R^{12} は一緒 になって形成する環を意味し、R¹³、R¹⁴、R¹⁵、及び R¹⁶はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、置換 基を有することもあるアルキル基、置換基を有すること もあるアリール基、R¹³とR¹⁴またはR¹⁵とR¹⁶が一緒 になって形成する環を意味し、yは0から3の整数を意 味する。)を意味し;m及びnは、それぞれ独立に、0 または1の整数を意味し;Qはカルボキシル基、置換基 を有することもあるアルコキシカルボニル基、一CONH-(5ーテトラゾリル)基、置換基を有することもある1,2,3ートリアゾリル基、置換基を有することもある2,4ージオキソチアゾリジンー5ーイリデニル基、置換基を有することもある4ーオキソー2ーチオキソチアゾリジンー5ーイリデニル基、置換基を有することもある4ーオキソー2ーチオキンチアゾリジンー5ーイリデニル基、置換基を有することもある5ーオキソー4ーテトラゾリル基、置換基を有することもある2ー(3,5ージオキソ)ー[1,2,4]オキサジアゾリニル基、置換基を有することもある5ー(3ーオキソ)ー[1,2,4]オキサジアゾリジニル基、電換基を有することもある5ー(3ーオキソ)ー[1,2,4]オキサジアゾリジニル基、または置換基を有することもある3ー(5ーオキソ)ーイソオキサゾリジル基で表される基を意味する。)]

(ただし、mおよびnが0であり、かつQがカルボキシル基またはアルコキシカルボニル基である場合を除く。)で表される化合物及びそれらの塩。

【請求項2】 式(1)中のR¹ が水素原子である請求項1または2に記載の化合物及びそれらの塩。

【請求項3】 式(1)中のR²が置換基を有することもあるアルキル基または置換基を有することもあるシクロアルキル基である請求項1ないし3のいずれか1項に記載の化合物及びそれらの塩。

【請求項4】 式(1)中のAが置換基を有することもあるフェニル基である請求項1ないし4のいずれか1項に記載の化合物及びそれらの塩。

【請求項5】 式(1)中のAで示される基がフェニル基であり、2-エチニルチアゾリル基と $-(G^1)_m-$ ($G^2)_n-Q$ で表される基とがメタ配置である請求項1ないし4のいずれか1項に記載の化合物及びそれらの4

【請求項6】 式(1)中のQが5ーテトラゾリル基である請求項1ないし5のいずれか1項に記載の化合物及びそれらの塩。

【請求項7】 式(1)中のm及びnが0である請求項 1ないし6のいずれか1項に記載の化合物及びそれらの 塩。

【請求項8】 式(1) 中のm及びnが1であり、G¹が-NR³ CO-であり、G²が1または2以上の置換基を有することもあるフェニル基である請求項1ないし6のいずれか1項に記載の化合物及びそれらの塩。

【請求項9】 式(1)中の G^2 が1または2以上の置換基を有することもあるフェニル基であり、 G^1 とQとがパラ配置である請求項1ないし6または請求項8のいずれか1項に記載の化合物及びそれらの塩。

【請求項10】 請求項1ないし9のいずれか1項に記載の化合物又はそれらの塩からなる医薬。

【請求項11】 請求項1ないし9のいずれか1項に記載の化合物又はそれらの塩を有効成分として含有するア

レルギー性疾患の治療及び/又は予防薬。

【請求項12】 請求項1ないし9のいずれか1項に記載の化合物又はそれらの塩を有効成分として含有するロイコトリエンが関与する疾患の治療及び/又は予防薬。

【請求項13】 請求項1ないし9のいずれか1項に記載の化合物又はそれらの塩を有効成分として含有するヒスタミンが関与する疾患の治療及び/又は予防薬。

【請求項14】 請求項1ないし9のいずれか1項に記載の化合物又はそれらの塩を有効成分として含有するロイコトリエン及びヒスタミンが同時に関与する疾患の治療及び/又は予防薬。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、抗アレルギー作用などの生理活性を有し、医薬の有効成分として有用なエチニルチアゾール誘導体に関する。

[0002]

【従来の技術】アレルギー性疾患に分類される気管支喘 息は気道の慢性炎症を特徴とする疾患であり、この原因 物質としてロイコトリエン(LTs)、トロンボキサン A₂(TXA₂)、血小板活性化因子(PAF)、ヒスタ ミン、プロスタグランジン(PG)等の様々な化学物質 (炎症性メディエーター) が関与が知られている。これ ら炎症性メディエーターの1つであるロイコトリエン類 は、アレルギー性の気管及び気管支疾患、アレルギー性 の肺疾患、アレルギー性ショック、またはアレルギー性 の各種炎症の発現に関与する主要な因子の一つと考えら れている (Proc. Natl. Acad. Sci. U SA. 80:1712-1716, 1983)。また、 ペプチドロイコトリエン (LTs) はアラキドン酸の代 謝によって産生される炎症性メディエーターであり、ロ イコトリエンC₄(LTC₄)、ロイコトリエンD₄(LT D₄)、及びロイコトリエンE₄ (LTE₄) が知られ Tいる (Science、220:568-575, 1 983)。

【0003】これらロイコトリエン類の受容体(レセプター)に結合し、ロイコトリエン類と拮抗する生理活性物質(受容体拮抗薬)が数多く報告されている(Chimia 46:304-311,1992、及びJ.Med.Chem.1996,39(14)2629-2654)。また、ロイコトリエン受容体拮抗薬の4-オキソ-8-(4-(4-フェニルプトキシ)ベンゾイルアミノ)-2-(テトラゾール-5-イル)-4H-1ーベンゾピラン・ヘミハイドレート(プランルカスト:Drugs of the Future 1988,13,317-320)についての臨床成績が報告されつつあり[医学のあゆみ、164(4):225-247、1993;免疫薬理、12巻(2):116(222)-118(224)、1994;及び、臨床医薬,9(S-1):71-107,1993など]、これら

のロイコトリエン受容体拮抗薬の有用性が認められつつ ある。

【0004】一方、肥満細胞、好酸球、好塩基球等は上記の炎症性メディエーターの産生細胞であり、アレルギー性の気管及び気管支疾患、アレルギー性の肺疾患、アレルギー性ショック、又はアレルギー性の各種炎症の病態において重要な役割を果たしている。代表的な炎症性細胞一つである肥満細胞では、感作された状態(抗原に対するIgE抗体が細胞表面のFcレセプターに結合した状態)で再び抗原に曝露されると細胞が活性化され、その結果、ヒスタミン、LTC4等のケミカルメディエーターが遊離され、血管透過性亢進、毛細血管拡張、平滑筋攣縮等を引き起こす。

【0005】この一連の反応を抑制する薬剤として、ジ ソディウム・クロモグリケート(DSCG)[The Merck Index, 第9版 2585 (197 6)] 及び9ーメチルー3ー(1Hーテトラゾールー5 ーオン・カリウム塩(ペミロラスト・カリウム)(特開 昭54-36294) 等が知られている。抗アレルギー 薬は、抗ヒスタミン作用を持つ塩基性抗アレルギー薬・ と、この作用を持たない酸性抗アレルギー薬とに分類さ れるが、ペミロラスト・カリウムは酸性抗アレルギー薬 の代表例である。酸性抗アレルギー薬は抗ヒスタミン作 用を有しないために口内乾燥感や眠気などの副作用がな いことを特徴を有しており、気管支喘息やアレルギー性 鼻炎に対してある程度の有効性が報告されている [現代 医療、26巻(7)137(2143)-139(21 45)、1994;現代医療、26巻(7)251(2 257) -255 (2261)、1994;及び、Pr ogress in Medicine、13巻(1 0) , 137 (2247) -147 (2257) , 1993]。しかしながら、これらの薬剤は気管支喘息に適 用できるものの、臨床的な満足度はさほど高くないとい う問題を有している。

[0006].

【発明が解決しようとする課題】上記抗アレルギー薬が臨床的に満足されていない理由として、アレルギー性疾患を惹起する原因物質(炎症性メディエーター)は各個人により異なり、複数の原因物質が同時に関与していることが多いこと、及びその原因物質を特定する診断技術が一般に煩雑であることが挙げられる。従って、抗アレルギー剤を用いてアレルギー疾患の予防や治療を行う場合、従来の抗アレルギー剤のように単独の作用を有する薬剤よりも、複数の抗アレルギー作用を同時に発揮する薬剤の方が、より広範囲のアレルギー疾患の予防や治療に有用であることが期待される。また、このように複数の作用を有する単一の薬剤を投与することによって、複数の薬剤を同時投与した際の薬物相互作用による作用の減弱、多様な副作用の発現、又は医療経済性の低下など

の問題を回避できる可能性がある。

【0007】とりわけ、臨床的な治療及び/又は予防効果が証明されているロイコトリエンに対する拮抗作用と、ヒスタミンなどのメディエーターの遊離抑制作用とを併せ持つ化合物を提供することができれば、より広範囲なアレルギー性疾患の治療及び/又は予防が可能になるものと期待される。従って、本発明の課題は、気管支喘息に代表されるアレルギー性疾患の治療及び/又は予防薬を提供することにあり、より具体的には、ロイコトリエン拮抗作用と肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用とを併せ持ち、アレルギー性疾患の治療及び/又は予防薬の有効成分として有用な化合物を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記の課題を達成するために鋭意研究を重ねた結果、下記の式で表されるエチニルチアゾール誘導体がロイコトリエン拮抗作用と肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用とを併せ持っていること、及び、該化合物を経口投与することにより、上記の二つの作用を同時に、かつ持続的に発現させることができることを見いだした。本発明は上記の知見を基にして完成されたものである。

【0009】すなわち本発明は、一般式(1): 【化2】

$$R^1$$
 $C \equiv C - A - (G^1)_m - (G^2)_n - Q$

 $[式中、<math>R^1$ 及び R^2 は、それぞれ独立して、水素原 子、ハロゲン原子、置換基を有することもあるアルキル 基、置換基を有することもあるシクロアルキル基、また $iR^1 & R^2$ が一緒になって形成する環を意味し; Aは 置換基を有することもあるフェニル基、置換基を有する こともあるピリジル基、置換基を有することもあるフリ ル基、置換基を有することもあるチエニル基、置換基を 有することもあるベンゾフラニル基、置換基を有するこ ともあるベンゾ [b] チエニル基、置換基を有すること もあるベンゾオキサゾリル基、置換基を有することもあ るベンゾチアゾリル基、置換基を有することもあるピリ ド[1, 2-a] ピリミジニル基、置換基を有すること もあるキナゾリニル基、置換基を有することもあるベン ソトリアジニル基、または置換基を有することもある2 H-クロメニル基を意味し: G1 は酸素原子、カルボニ ル基、エチニル基、基-NR³ CO-、基-NR⁴ -、 基-NR⁵ SO₂ -、基-SO₂ NR⁶ -、基-CON $R^7 -$ 、基 $-C (= CHR^8) -$ 、または、基 $-CR^9$ $=CR^{10}-$ (ここで、式中、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 及びR⁷ は水素原子、水酸基、または置換基を有するこ

ともあるアルキル基を意味し、R⁸ はシアノ基、カルボ キシル基、または置換基を有することもあるアルコキシ カルボニル基を意味し、R⁹ 及びR¹⁰は、それぞれ独立 して、水素原子、ハロゲン原子、置換基を有することも あるアルキル基、置換基を有することもあるシクロアル キル基、置換基を有することもあるアリール基、または R⁹ 及びR¹⁰が一緒になって形成する環を意味する。) を意味し; G² は置換基を有することもあるフェニル 基、置換基を有することもあるピリジル基、置換基を有 することもあるチアゾリル基、置換基を有することもあ るイソオキサゾリル基、置換基を有することもあるチエ ニル基、置換基を有することもあるピリミジニル基、基 -CHR¹¹-CHR¹²-、または基-CR¹³=CR¹⁴-(CR¹⁵=CR¹⁶) y- (ここで、式中、R¹¹とR¹²は 一緒になって形成する環を意味し、R¹³、R¹⁴、R¹⁵、 及びR¹⁶はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、 置換基を有することもあるアルキル基、置換基を有する こともあるアリール基、R¹³とR¹⁴またはR¹⁵とR¹⁶が 一緒になって形成する環を意味し、yは0から3の整数 を意味する。) を意味し; m及びnは、それぞれ独立に 0または1の整数を意味し;Qはカルボキシル基、置換 基を有することもあるアルコキシカルボニル基、-CO NH- (5-テトラゾリル) 基、置換基を有することも ある5-テトラゾリル基、置換基を有することもある 1, 2, 3-トリアゾリル基、置換基を有することもあ る2. 4-ジオキソチアゾリジン-5-イリデニル基、 置換基を有することもある4-オキソー2-チオキソチ アゾリジン-5-イリデニル基、置換基を有することも ある5-オキソー4-テトラゾリル基、置換基を有する こともある3-(5-オキソ)-[1, 2, 4]オキサ ジアゾリジニル基、置換基を有することもある2-(3, 5-3) (3, 5-3) (3, 5-3) (3, 5-3) (3, 5-3)ニル基、置換基を有することもある5-(3-オキソ) [1, 2, 4] オキサジアゾリジニル基、または置換 基を有することもある3-(5-オキソ)ーイソオキサ

(ただし、mおよびnが0であり、かつQがカルボキシル基またはアルコキシカルボニル基である場合を除く。)で表される化合物及びそれらの塩を提供するものである。

【0010】上記発明の好ましい態様によれば、式

ゾリジル基で表される基を意味する。)]

(1) 中の R^1 が水素原子である上記化合物及びそれらの塩;式(1) 中の R^2 が置換基を有することもあるアルキル基または置換基を有することもあるシクロアルキル基である上記化合物及びそれらの塩;式(1) 中のAが置換基を有することもあるフェニル基である上記化合物及びそれらの塩;式(1) 中のAで示される基がフェニル基であり、2-x チニルチアゾリル基とー(G^1)_m ー(G^2) $_n$ ーQで表される基とがメタ配置である上記化合物及びそれらの塩;式(1) 中のQが5ーテトラゾ

リル基である上記化合物及びそれらの塩;式(1)中の m及びnが0である上記化合物及びそれらの塩;式

(1) 中のm及びnが1であり、 G^1 が $-NR^3$ CO-であり、 G^2 が1個または2個以上の置換基を有することもあるフェニル基である上記化合物及びそれらの塩;並びに、式(1)中の G^2 が1個または2個以上の置換基を有することもあるフェニル基であり、 G^1 とQとがパラ配置である上記化合物及びそれらの塩が提供される。

【0011】本発明の別の態様によれば、上記化合物又はそれらの塩からなる医薬;並びに、その好ましい態様として、上記化合物又はそれらの塩を有効成分として含有するアレルギー性疾患の治療及び/又は予防薬が提供される。また、上記化合物又はそれらの塩を有効成分として含有するロイコトリエンが関与する疾患、好ましくはロイコトリエンが関与するアレルギー性疾患の治療及び/又は予防薬が提供される。さらに、上記化合物又はそれらの塩を有効成分として含有するヒスタミンが関与する疾患、好ましくはヒスタミンが関与するアレルギー性疾患の治療及び/又は予防薬が提供される。さらに、該疾患がヒスタミンの発現過多に起因するアレルギー性疾患である上記治療及び/又は予防薬が提供される。

【0012】また、本発明の特に好ましい態様ににより、上記化合物又はそれらの塩を有効成分として含有するロイコトリエン及びヒスタミンが関与する疾患、好ましくはロイコトリエン及びヒスタミンが関与するアレルギー性疾患の治療及び/又は予防薬;並びに、該疾患がロイコトリエン及びヒスタミンの発現過多に起因するアレルギー性疾患である上記治療及び/又は予防薬が提供される。さらに、本発明の別の態様によれば、ロイコトリエン及び/又はヒスタミンが関与する疾患、好ましくはロイコトリエン及び/又はヒスタミンが関与するアレルギー性疾患の治療及び/又は予防方法であって、上記化合物又はそれらの塩から選ばれる物質の有効量をヒトを含む哺乳類動物に投与する工程を含む方法;並びに、上記アレルギー性疾患の治療及び/又は予防剤の製造のための上記化合物又はそれらの塩の使用が提供される。

[0013]

【発明の実施の形態】本明細書において「アルキル基」とは、例えば、炭素数1から12の直鎖状若しくは分枝 鎖状の飽和炭化水素を意味しており、「シクロアルキル 基」とは、例えば、3から8員の環状アルキル基を意味 している。また、「ハロゲン原子」という用語は、特に 言及しない場合には、フッ素原子、塩素原子、臭素原 子、及びヨウ素原子のいずれも含む概念として用いる。 「アルコキシル基」としては、例えば、炭素数1から1 2の直鎖状若しくは分枝鎖状のアルコキシル基を用いる ことができる。

 ${ [0014] R^1 及びR^2 はそれぞれ独立して水素原$ 子、ハロゲン原子、置換基を有することもあるアルキル 基、置換基を有することもあるシクロアルキル基、また はR¹とR²が一緒になって形成する環を意味する。ア ルキル基としては、好ましくは、炭素数1から8の直鎖 状若しくは分枝鎖状のアルキル基、より好ましくは炭素 数1から5の直鎖状もしくは分枝鎖状のアルキル基を用 いることができる。具体的には、例えば、メチル基、エ チル基、プロピル基、イソプロピル基、ノルマルブチル 基、イソプチル基、第三プチル基、及びペンチル基等な どを用いることができる。上記アルキル基に結合する置 換基としては、例えば、ハロゲン原子、フェニル基、メ トキシフェニル基、ハロゲノフェニル基、ベンジル基、 メトキシベンジル基、ジメトキシベンジル基、又はハロ ゲノベンジル基等から選ばれる1個又は2個以上、好ま しくは1個の置換基を挙げることができる。 ハロゲノフ ェニル基としてはクロルフェニル基、ハロゲノベンジル 基としてはクロルベンジル基などを用いることができ る。

【0015】R¹ 及びR² が示すシクロアルキル基としては、好ましくは炭素数3から5のシクロアルキル基、例えばシクロプロピル基、シクロブチル基、及びシクロペンチル基を用いることができる。上記シクロアルキル基に結合する置換基としては、例えば、ハロゲン原子等を挙げることができる。R¹ とR² とが一緒になって形成する環としては、5ないし8員環、好ましくは6又は7員環を挙げることができ、例えば、シクロヘキサン環、ベンゼン環またはシクロヘブタン環等を用いることができる。R¹ 及びR² の組み合わせとしては、R¹ が水素原子であり、R² が置換基を有することもあるアルキル基又は置換基を有することもあるシクロアルキル基である場合が好ましい。

【0016】Aは置換基を有することもあるフェニル基、置換基を有することもあるピリジル基、置換基を有することもあるチェニル基、置換基を有することもあるベンゾフラニル基、置換基を有することもあるベンゾ [b] チェニル基、置換基を有することもあるベンゾオキサゾリル基、置換基を有することもあるベンゾチアゾリル基、置換基を有することもあるペンゾチアゾリル基、置換基を有することもあるペンゾナンジニル基、置換基を有することもあるペンゾトリアジニル基、置換基を有することもあるクロメニル基を意味する。置換基としては1個又は2個以上、好ましくは1個のハロゲン原子を用いることができる。Aが置換基を有することもあるフェニル基であることが好ましい。

【0017】 G^1 は酸素原子、カルボニル基、エチニル 基、基 $-NR^3$ CO-、基 $-NR^4$ -、基 $-NR^5$ SO $_2$ -、基 $-SO_2$ NR^6 -、基 $-CONR^7$ -、基 $-(C=CHR^8$ -、または基 $-CR^9$ $=CR^{10}$ -を意味 する。これらのうち、基-NR3 CO-が好ましい。上 記の基において、R³、R⁴、R⁵、R⁶及びR⁷は、 それぞれ、水素原子、水酸基、または置換基を有するこ ともあるアルキル基を意味している。アルキル基として は、好ましくは、炭素数1から8の直鎖状若しくは分枝 鎖状のアルキル基、より好ましくは炭素数1から5の直 鎖状若しくは分枝鎖状のアルキル基を用いることができ る。例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプ ロピル基、ノルマルブチル基、イソブチル基、又はペン チル基等を用いることができる。上記のアルキル基は、 例えば、ハロゲン原子、置換基を有することもあるフェ ニル基、カルボキシル基、またはアルコキシカルボニル 基等から選ばれる1個又は2個以上の置換基、好ましく は1個の置換基を有していてもよい。R3、R4、 R^5 、 R^6 及び R^7 はそれぞれ水素原子であることがが 好ましい。

【0018】 R8 は、シアノ基、カルボキシル基、また は置換基を有することもあるアルコキシカルボニル基を 意味する。アルコキシカルボニル基としては、メトキシ カルボニル基、エトキシカルボニル基、または4-メト キシベンジルカルボニル基を挙げることができる。R⁹ 及びR10はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、 置換基を有することもあるアルキル基、置換基を有する こともあるシクロアルキル基、置換基を有することもあ るアリール基、またはR⁹ 及びR¹⁰が一緒になって形成 する環を意味する。シクロアルキル基としては、好まし くは炭素数3から5のシクロアルキル基、例えばシクロ プロピル基、シクロブチル基、及びシクロペンチル基を 用いることができる。上記シクロアルキル基に結合する 置換基としては、例えば、ハロゲン原子等を挙げること ができる。R⁹ 及びR¹⁰が一緒になって形成する環とし ては、5ないし8員環、好ましくは6又は7員環を挙げ ることができ、例えば、シクロヘキサン環、ベンゼン環 またはシクロヘプタン環等を用いることができる。アリ ール基としてはフェニル基などを用いることができ、ア リール基上の置換基としては、例えば、ハロゲン原子等 を用いることができる。R⁹ 及びR¹⁰が水素原子である ことが好ましい。

【0019】 G^2 は置換基を有することもあるフェニル基、置換基を有することもあるピリジル基、置換基を有することもあるイソオキサゾリル基、置換基を有することもあるイソオキサゾリル基、置換基を有することもあるチェニル基、置換基を有することもあるチェニル基、置換基を有することもあるピリミジニル基、基ーCHR 11 ーCHR 12 ー、または基ーCR 13 =CR 14 ー(CR 15 =CR 16)yーを意味する。上記フェニル基などに存在する置換基の個数は特に限定されず、1個又は2個以上の置換基が存在していてもよい。特に、上記フェニル基については、2個以上の置換基が存在していることが好ましい場合もある。このような置換基は、例えば、ハロゲン原子、ニトロ基、置換基を有することもあ

るアミノ基、置換基を有することもあるアルキル基、置換基を有することもあるアルケニル基、置換基を有することもあるアルキニル基、水酸基、置換基を有することもあるアルコキシル基、置換基を有することもあるアルキルまたはアリールスルホニル基、置換基を有することもあるアルキルまたはアリールスルホニル基、置換基を有することもあるアルキンはではアリールスルフィニル基、カルボキシル基、または置換基を有することもあるアルコキシカルボニル基などから選ばれる。R¹¹及びR¹²が一緒になって形成する環としては、例えば、炭素数3から6の環状アルキル基を挙げることができ、具体的には、シクロプロパン環、シクロペンタン環、シクロペキサン環、又はシクロペキセン環などを好適に用いることができる。

【0020】上記の基において、R¹³、R¹⁴、R¹⁵、及びR¹⁶はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、置換基を有することもあるアルキル基、または置換基を有することもあるアリール基、R¹³とR¹⁴とが一緒になって形成する環を意味する。R¹³及びR¹⁴は水素原子、ハロゲン原子、又は置換基を有することもあるアルキル基であることが好ましく、R¹⁵、及びR¹⁶は水素原子であることが好ましい。R¹³とR¹⁴とが一緒になって、またはR¹⁵とR¹⁶とが一緒になって形成する環としては、シクロプロパン環、シクロペンタン環、シクロペンテン環、シクロペンタン環、シクロペンテン環、シクロペンテン環、シクロペンタン環、シクロペンテン環、シクロペンタン環、シクロペンテン環、シクロペンタン環、シクロペンテン環、シクロペンタン環、シクロペンテン環、シクロペンタン環、シクロペンテン環、シクロペンタン環、シクロペンテン環、シクロペンタン環、シクロペンテン環、シクロペンタン環、シクロペンテン環、シクロペンテン環、シクロペンテン環、シクロペンテン環、シクロペンテン環、シクロペンタン環、シクロペンテン環、シクロペンテン環、シクロペンタン環、シクロペンテン環、シクロペンテン環、シクロペンタン環、シクロペンテン環、シクロペンタン環、シクロペンタン環、シクロペンタン環、シクロペンタン環、シクロペンタン環、シクロペンタンである。

【0021】式(1) においてm及びnは、0または1 の整数を意味する。m及び/又はnが0の場合には、G 1 及び/又はG² は単結合を示す。Qはカルボキシル 基、置換基を有することもあるアルコキシカルボニル 基、-CONH-(5-テトラゾリル)基、置換基を有 することもある5-テトラゾリル基、置換基を有するこ ともある1,2,3-トリアゾリル基、置換基を有する こともある2、4ージオキソチアゾリジン-5ーイリデ ニル基、置換基を有することもある4-オキソー2ーチ オキソチアゾリジンー5ーイリデニル基、置換基を有す ることもある5-オキソー4-テトラゾリル基、置換基 を有することもある3-(5-オキソ)-[1, 2, 4] オキサジアゾリジニル基、置換基を有することもあ る2-(3,5-ジオキソ)-[1,2,4]オキサジ アゾリニル基、置換基を有することもある5-(3-オ キソ) - [1, 2, 4] オキサジアゾリジニル基、また は置換基を有することもある3-(5-オキソ)ーイソ オキサゾリジル基を意味するが、これらのうち、5-テ トラゾリル基が好ましい。

【0022】式(1)の化合物においてR¹及びR³は 水素原子であることが好ましい。Aはフェニル基である ことが好ましく、Aを介して2-エチニルチアゾリル基 と基一 (G^1) m $- (G^2)$ n - Qとがメタ配置で結合し ていることが好ましい。Qは5-テトラソリル基である ことが好ましい。 $mが1のとき、<math>G^1$ が基 $-NR^3$ CO ーであることが好ましく、nが1のとき、G2 がフェニ ル基であることが好ましい。G² がフェニル基を示す場 合、フェニル基上には1個の置換基又は2個以上の置換 基が存在していてもよいが、2個以上の置換基が存在す る場合にはそれらは同一でも異なっていてもよい。フェ ニル基上の置換基としては、例えば、フッ素原子、塩素 原子等のハロゲン原子:メチル基、エチル基、プロピル 基、nープチル基、イソプチル基、ヒドロキシメチル 基、アセトキシメチル基、1-プロペニル基、2-プロ ペニル基、エチニル基、又は1-プロピニル基等のアル キル基、アルケニル基、又はアルキニル基;エトキシル 基、nープロポキシル基、nープトキシル基、イソプト キシル基、2-フルオロエトキシル基、2,2,2-ト リフルオロエトキシル基、フェノキシル基、ベンジルオ キシ基等のアルコキシル基;エチルチオ基、n-プロピ ルチオ基、プチルチオ基、ベンジルチオ基、2-ヒドロ キシエチルチオ基などのアルキルチオ基、及びこれらの アルキルチオ基の硫黄原子を酸化して得られるアルキル スルフォニル基;メチルアミノ基、n-ブチルアミノ基 等のアルキルアミノ基等を用いることができる。

【0023】R²としてはシクロブチル、イソプロピル、tertーブチル、又はシクロププロピル基が好ましい。Aが置換基を有するフェニル基である場合、該置換基としてはフッ素原子が好ましい。A及びG²がそれぞれ置換基を有するフェニル基を示す場合、それぞれのフェニル基上の置換基を種々組み合わせて得られる化合物はいずれも本発明の化合物の範囲に包含されることはいうまでもない。

【0024】本発明の好ましい化合物として、5-(3 - (2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニ (1) フェニル) -1 H - テトラゾール; 5 - (3 - (2- (4-イソプロピル-2-チアゾリル) エチニル) フ ェニル) -1H-テトラゾール; 5-(3-(2-(4ーシクロプロピルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ (μ) -1H-テトラゾール; 5-(3-(2-(4-n) ープロピルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) ー 1H-テトラゾール; 5- (3-(2-(4-シクロブ チルー2ーチアゾリル) エチニル) -2-フルオロフェ ニル) -1H-テトラゾール; 5- (3-(2-(4-シクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ーフル オロフェニル) -1 H - テトラゾール; 5 - (3 - (2(4-イソプロピルー2ーチアゾリル)エチニル)ー 2-フルオロフェニル) -1H-テトラゾール;5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エ チニル) -2-メチルフェニル) -1H-テトラゾー ル:5-(3-(2-クロロ-2-(4-シクロプチル -2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-テト

ラゾール; 5-(4-(2-(4-シクロプチル-2-チアソリル) エチニル) -2-チエニル) -1Hーテトラゾール; 5-(5-(2-(4-シクロプチル-2-チアソリル) エチニル) -3-ピリジル) -1Hーテトラゾール; 5-(5-(2-(4-シクロプチル-2-チアソリル) エチニル) -2-ベンソオキサゾリル) -1Hーテトラゾール; 5-(5-(2-(4-シクロプチル-2-チアソリル) エチニル) -2-ベンゾ [b] チエニル) -1Hーテトラゾール; 5-(6-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -2 -オキソー2Hーベンソピラン-3-イル) -1Hーテトラゾール; 及び3-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -4H-[1, 2, 4] -オキサジアゾール-5-オン等の化合物を挙げることができる。

【0025】また、さらに好ましい化合物として、式 (1) 中のm及Unが1であり、A及UG² がフェニル 基である化合物、例えば、N-(4-(1H-テトラゾ ールー5ーイル)フェニルー3ー(2-(4-シクロブ チルー2-チアゾリル) エチニル) ベンズアミド: N-(3-(1H-テトラゾール-5-イル)フェニル-3 - (2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニ ル) ベンズアミド; N-(2-メトキシ-4-(1H-テトラゾールー5ーイル)フェニル)ー3ー(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ベンズア ミド; N- (2-メチル-4-(1H-テトラゾールー 5-イル) フェニル) -3-(2-(4-シクロブチル -2-チアゾリル) エチニル) ベンズアミド; N-(2 -フルオロ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)フ ェニル) -3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾ リル) エチニル) ベンズアミド: N-(3-(2-(4 ーシクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ ル) -3-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズア ミド; N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チア ソリル) エチニル) -6-フルオロフェニル) -4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エ チニル) -6-フルオロフェニル) -2-フルオロ-4 - (1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド; N - (3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル)フェニル)-3-メチル-4-(1H-テト ラゾール-5ーイル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロプチルー2-チアソリル) エチニル) フェ ニル) -3-メトキシ-4- (1H-テトラゾール-5 ーイル) ベンズアミド; N- (3- (2- (4-ter tープチルー2ーチアソリル) エチニル) フェニル) ー 2-フルオロー4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド: N-(3-(2-(4-シクロプチルー 2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-クロロー 4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミド:

 $N - (3 - (2 - (4 - \nu) / 2 - 7 + \nu))$ ル) エチニル) フェニル) -2-メチル-4- (1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニ ル) フェニル) -2-メトキシ-4- (1H-テトラゾ ールー5-イル) ベンズアミド; N- (3- (2- (4 ーシクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ ル) -2-メチルチオ-4- (1H-テトラゾール-5 ーイル) ベンズアミド; N- (3-(2-(4-シクロ ブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) ー2ー アミノー4ー (1H-テトラゾールー5ーイル) ベンズ アミド: N- (3-(2-(4-シクロプチル-2-チ アゾリル) エチニル) フェニル) -4- (1H-テトラ ゾール-5-イル) -2-ビニルベンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エ チニル)フェニル)ー4ー(1H-テトラゾールー5ー イル) -2-トリフルオロメトキシベンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エ チニル) フェニル) -2-ヒドロキシ-4- (1H-テ トラゾールー5-イル) ベンズアミド; N-(3-(2 (4-シクロプチルー2-チアゾリル)エチニル)フ ェニル) -2, 6-ジフルオロ-4-(1H-テトラゾ ールー5-イル) ベンズアミド;及びN-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェ ニル) -2, 6-メチル-4- (1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド等を挙げることができる。上記 化合物のR² 部分であるシクロプチル基をシクロプロピ ル基、イソプロピル基、tert-ブチル基等に置換し た化合物も同様に本発明の好ましい化合物である。

【0026】さらに、同様に製造可能な化合物として、 例えば、N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チ アゾリル) エチニル) -6-フルオロフェニル) -2-クロロー4- (1H-テトラゾール-5-イル) ベンズ アミド; N- (3-(2-(4-シクロプチル-2-チ アゾリル) エチニル) -6-フルオロフェニル) -2-ヒドロキシー4ー(1Hーテトラゾールー5ーイル)べ ンズアミド; N- (3- (2- (4-シクロプチル-2 ーチアソリル) エチニル) -6-フルオロフェニル) -2-メチル-4- (1H-テトラゾール-5-イル) ベ ンズアミド: N- (3- (2- (4-シクロプチル-2 -チアゾリル) エチニル) -6-フルオロフェニル) -2-メチルチオ-4-(1H-テトラゾール-5-イ ル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロブチ ルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ーフルオロフェニ ル) -2-メチルスルフィニル-4-(1H-テトラゾ ール-5-イル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4 ーシクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ーフ ルオロフェニル) -2-メチルアミノ-4-(1H-テ トラゾール-5-イル) ベンズアミド; N-(3-(2 - (4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -

6-フルオロフェニル)-2-アミノ-4-(1H-テ トラゾール-5-イル) ベンズアミド; N-(3-(2 -(4-シクロプチル-2-チアソリル)エチニル)-6-フルオロフェニル) -2-プチルアミノ-4-(1 H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド; N-(3 - (2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニ ル) -6-フルオロフェニル) -2、6-ジクロロ-4 - (1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド; N - (3-(2-(4-シクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-6-ヒドロキシ -4- (1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミ ド: N- (3- (2- (4-シクロプチル-2-チアゾ リル) エチニル) フェニル) -2-フルオロー6-メチ ルアミノー4ー(1Hーテトラゾールー5ーイル)ベン ズアミド; N- (3- (2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-アミノ-6-フルオロー4ー(1H-テトラゾール-5-イル)ベン ズアミド; N- (3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-ブチルアミノ -6-フルオロ-4-(1H-テトラゾール-5-イ ル) ベンズアミド; N- (3- (2- (4-シクロプチ ルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) ー2ーフル オロー6-メチルスルフィニル-4-(1H-テトラゾ ール-5-イル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ ル) -2-フルオロー6-ヒドロキシメチルー4ー(1 H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド; N-(3 **- (2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニ** ル)フェニル) -2-(2-フルオロエトキシ) -4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エ チニル) フェニル) -2-(2,2,2-トリフルオ ロ) エトキシ) -4- (1H-テトラゾール-5-イ ル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロブチ ルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) ー2ーメチ ルスルフィニルー4ー(1 Hーテトラゾールー5ーイ ル) ベンズアミド; N- (3- (2- (4-シクロブチ ルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) ー2ーnー プチルアミノー4ー (1Hーテトラゾールー5ーイル) ベンズアミド; N-(3-(2-(4-シクロプチルー 2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2- (2-ヒ ロロキシエチル) チオー4-(1H-テトラゾール-5 ーイル) ベンズアミド; N- (3-(2-(4-シクロ ブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) ー2ー エチニルー4ー (1Hーテトラゾールー5ーイル) ベン ズアミド; N- (3-(2-(4-シクロプチルー2-チアソリル) エチニル) フェニル) -2- (1-プロペ ニル) -4- (1H-テトラゾール-5-イル) ベンズ アミド: 及びN-(3-(2-(4-シクロプチル-2))ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2- (2-プロ

ペニル) -4-(1H-Fトラゾール-5-イル) ベンズアミド等を挙げることができる。上記化合物の R^2 部分であるシクロプチル基をシクロプロピル基、イソプロピル基、tert-プチル基等に置換した化合物についても、同様に合成可能な化合物である。

【0027】式(1)で表される本発明の化合物は、置換基の種類により、1個又は2個以上の不斉炭素を有する場合があるが、1個又は2個以上の不斉炭素に基づく光学的に純粋な任意の異性体、任意の光学異性体の混合物、又はラセミ体は、いずれも本発明の範囲に包含される。また、2個以上の不斉炭素に基づくジアステレオ異性体の任意の混合物も本発明の範囲に包含される。さらに、例えば、テトラゾール基などを有する本発明の化合物には互変異性体が存在する場合があるが、それぞれの互変異性体又はそれらの任意の混合物も本発明の範囲に包含されることを理解すべきである。本発明の化合物

は、置換基の種類によっては酸付加塩又は塩基付加塩を 形成する場合があり、さらに、遊離形態の化合物または その塩の形態の化合物が水和物又は溶媒和物として存在 する場合があるが、これらは全て本発明の範囲に包含さ れる。

【0028】本発明の化合物は、例えば、以下の [スキーム1] から [スキーム8] に従って合成することができる。式 (1) で表される化合物は、 [スキーム1] に示すように、エチニルチアゾール類 (2) と式 (3) の化合物とのカップリング反応によって製造することができる (スキーム中、 R^1 、 R^2 、A、 G^1 、 G^2 、Q、m、及びnは前記と同義であり、Lはポリフルオロスルフォニルアルコキシル基、または臭素若しくはヨウ素などの脱離基を表す)。

【化3】

[スキーム1]

$$R^1$$
 R^2
 R^2

【0029】 「スキーム1] に示す2-エチニルチアゾ ール(2)は公知の方法で製造可能である。2-エチニ ルチアゾール(2)と化合物(3)とを、それ自体文献 公知の方法に従って、適宜の不活性溶媒中、例えばテト ラヒドロフラン若しくは1,2-ジメトキシエタンなど の不活性エーテル系溶媒、トリエチルアミン若しくはジ イソプロピルアミンなどの有機アミン系溶媒、または N、N-ジメチルホルムアミドなどの不活性極性溶媒中 で、0℃~溶媒の沸点の範囲の温度下でカップリングさ せることにより、式(1)の化合物を製造することがで きる。反応は、トリフェニルホスフィン及びヨウ化第一 銅の存在下または非存在下で行ってもよく、パラジウム [2] アセテート、テトラキス(トリフェニルホスフィ ン) パラジウム [0] またはビス (トリフェニルホスフ ィン) パラジウム [2] ジクロライドを触媒量、好まし くは0.1~10%モル程度の量添加してもよい。反応 を窒素またはアルゴン等の不活性気体の気流下で行うこ ともできる。

【0030】式(1)で示される化合物において、Qが 置換基を有することもあるアルコキシカルボニル基の場 合には、該化合物を酸性またはアルカリ加水分解に付す ることにより、対応の遊離カルボン酸型化合物に変換す ることができる。また、Qが環状の複素環基であって、 その環状に置換ベンジル基、または2-(トリメチルシ リル) エトキシメチル基などの保護基が置換基として存 在している場合には、これらの化合物を公知の脱保護反 応に付すことにより、Qが酸性の水素原子を有する遊離 形態の環状酸性基である化合物を製造することができ る。例えば、置換ベンジル基、4-メトキシベンジル基 が置換基として存在する場合には、生成するカチオンの スカベンジャーであるアニソールなどの存在下で、トリ フルオロ酢酸中で0℃から溶媒の沸点の温度の範囲、好 ましくは室温から溶媒の沸点温度の範囲で反応を行うこ とによって置換ベンジル基や4ーメトキシベンジル基を 除去することができる。また、複素環上に2-(トリメ チルシリル) エトキシメチル基などを保護基として有す る化合物は、例えばテトラヒドロフランなどの不活性エーテル系溶媒中で、テトラーnーブチルアンモニウムフルオリドまたはセシウム・フルオリドで処理することにより、該保護基を除去することができる。この反応の際、等量の酢酸を加えてもよい。

【0031】以下の[スキーム2]には、上記反応に原

料化合物として用いられる2-x チェルチアゾール (2) の合成法を示した(スキーム中、 R^1 及び R^2 は前記と同義であり、X は塩素原子又は臭素原子を表す)。

【化4】

[スキーム2]

【0032】2ーチアゾールエステル類(7)は、2ーハロゲノケトン類(5) [それ自体公知であるか、公知の方法により化合物(4)から容易に製造でき、市販品を入手可能な場合もある]と、市販品を入手可能なチオアミド化合物 [エチル・チオオキザメート(6)] とをエチルアルコールなどの不活性アルコール系溶媒中または酢酸中で0℃~溶媒の沸点の範囲の温度下に反応させることによって製造することができる。エステル体

(7) は公知の還元方法でアルコール体 (8) に変換することができる。還元反応は、例えば水素化ホウ素ナトリウムなどの還元剤を用い、エチルアルコールなどの不活性アルコール系溶媒中で、-20~50℃の範囲、好ましくは0℃~室温下に行うことができる。アルコール体 (8) は1級水酸基をアルデヒドに酸化する公知の方法に従ってアルデヒド体 (9) に変換できる。この酸化反応は、例えば、塩化メチレンなどの不活性ハロゲン化炭化水素系溶媒中で、-78℃~溶媒の沸点の範囲、好ましくは-78℃~室温下にクロム酸類を用いた酸化またはスワーン(Swern)酸化等を行うか、トルエンなどの不活性炭化水素系溶媒中またはアセトンなどの不活性ケトン系溶媒中で、0℃~溶媒の沸点の範囲、好ましくは室温~溶媒の沸点の範囲の温度下に活性二酸化マ

ンガンと処理することにより行うことができる。

【0033】2ーエチニルチアゾール (2) はアルデヒド体 (9) から次の方法で合成することもできる。リチウムジイソプロピルアミドまたはリチウムへキサメチルジシラジドを塩基として用い、テトラヒドロフランなどの不活性エーテル系溶媒中でトリメチルシリルジアゾメタンまたはジアゾメタンを-100℃~-20℃、好ましくは-50℃以下で処理することによってジアゾメタン類のカルバニオンを生成させる。このカルバニオンを含む溶液に2ーチアゾールカルバルデヒド (9) を好ましくは-50℃以下の温度で加え、ついで0℃~室温に昇温することによって転位成績体である2ーエチニルチアゾール (2) を得ることができる。

【0034】別法として、2-エチニルチアゾール

(2)を次のように合成してもよい。文献記載の方法に従い、2ーチアゾールカルバルデヒド(9)を、塩化メチレンなどの不活性ハロゲン化炭化水素系溶媒中で、例えば、四臭化炭素及びトリフェニルホスフィン等のリン試薬と-20℃~溶媒の沸点の範囲、好ましくは0℃度~室温下に反応させることにより、1,1ージプロモー2-(2ーチアゾリル)エチレン体(10)を得ることができる。ついで、化合物(10)をテトラヒドロフラ

ンなどの不活性エーテル系溶媒中で、-78℃~室温、好ましくは-78~0℃の範囲の温度下に、1.8~3等量程度のn-ブチルリチウムなどの有機アルキルリチウムと処理した後、-78~30℃の範囲、好ましくは0℃以下の低温下に希塩酸などの希鉱酸または飽和塩化アンモニウム水溶液等で中和することにより2-エチニルチアゾール(2)を得ることができる。

【0035】 [スキーム1] に用いられる化合物(3)

は、下記 [スキーム3] に示すように、化合物(1 1] の R^{17} をQに変換する方法によって合成することができる(スキーム中、A、 G^1 、 G^2 、Q、m、n、及び L は前記と同義であり、 R^{17} はシアノ基、ホルミル基、アセチル基、カルボキシル基、カルバモイル基、ヒドロキルアミノ基、またはアミノ基を表す。)

【化5】

[スキーム3]

L-A-
$$(G^1)_m$$
- $(G^2)_n$ - R^{17} — L-A- $(G^1)_m$ - $(G^2)_n$ - Q

【11】 【0036】下記 [スキーム3A] には、「スキーム3] に従う反応の具体的例示として、Aがフェニル基、m及びnが0、Lが臭素原子、R¹⁷がシアノ基である化合物(11a)から、Qが4ーメトキシベンジル基又は2ー(トリメチルシリル)エトキシメチル基を保護基として有するテトラゾリル基である化合物(3b)、及びLがヨウ素原子である化合物(3c)を合成する方法を 示す (スキーム中、R¹⁸は水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、置換基を有するアルキル基、置換基を有するアルコキシ基、またはアルコキシカルボニル基を示し、R¹⁹は4-メトキシベンジル基又は2-(トリメチルシリル)エトキシメチル基を意味する。)。

【化6】

[スキーム3A]

【0037】ベンゾニトリル体(11a)はそれ自体公知であるか、又は公知の方法により製造でき、シアノ基をテトラゾリル基に変換する公知の反応に従って、ベンゾニトリル体(11a)からテトラゾール体(3a)を製造することができる。例えば、N,Nージメチルホルムアミドなどの不活性極性溶媒中で、ベンゾニトリル体(11a)をアルミニウムアジドまたはアンモニウムアジドと例えば室温~溶媒の沸点の範囲の温度下に処理することによりテトラゾール体(3a)を得ることができる。上記反応に用いられるアルミニウムアジド又はアンモニウムアジドは、公知の方法に従い、ナトリウムアジ

ドを塩化アルミニウム、又は塩化アンモニウム、ピリジン塩酸塩などの4級アンモニウム塩で処理することにより容易に調製することができる。

【0038】テトラゾール体(3a)は、次のカップリング反応を行うために好適な保護基を導入しておくことが好ましい。保護基としては先に説明した置換ベンジル基、または2-(トリメチルシリル)エトキシメチル基が好ましい。保護基の導入の反応条件は以下のとおりである。例えば、テトラゾール体(3a)をN,Nージメチルホルムアミドなどの不活性極性溶媒中で、例えば炭酸カリウムの無機塩基の存在下に、4-メトキシベンジ

ルクロリドまたは2-(トリメチルシリル)エトキシメチルクロリドと0℃~溶媒の沸点の範囲、好ましくは室温から80℃の範囲の温度で処理することによって保護基を導入することができる。一般的に、テトラソリル基のアルキル化は1位置換体と2位置換体との混合物を与えるが、両者はシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーによって分離することができる。化合物(3b)の臭素原子をヨウ素原子に変換することにより化合物(3c)を得ることができる。例えば、N,Nージメチルホルムアミドなどの不活性極性な媒中で、化合物(3b)をヨウ化第一銅及びヨウ化カリウムと好ましくは80℃から溶媒の沸点の範囲の温度で加熱することにより化合物(3c)を製造することができる。

【0039】下記の [スキーム4] には、化合物(1

2)から G^1 を完成させることによって化合物(3 d)を合成する方法を示す。また、 [スキーム4 A] には、Aがフェニル基である化合物(1 2 a)から、Qが保護基として4-メトキシベンジル基又は2-(トリメチルシリル)エトキシメチル基を有する5-テトラゾール基である化合物(3 d)を合成する方法を示した [スキーム中、L、A、 G^1 、 G^2 、n、Q及び R^{18} は前記と同義であり、mは1であり、 R^{20} はホルミル基、アセチル基、カルボキシル基、N-メトキシーN-メチルカルバモイル基、置換基を有することもあるアミノ基、チオール基、又はクロルスルフォニル基を表し、 R^{21} は4-メトキシベンジル基または2-(トリメチルシリル)エトキシメチル基を表す。]。

【0040】

[スキーム4]

L-A-R²⁰ L-A-G¹-(G²)_n-Q
(12) (3d)
$$[(18]$$

[スキーム 4A]

【0042】R²⁰がホルミル基またはアセチル基であるベンズアルデヒド誘導体又はアセトフェノン誘導体(12a)から、G¹が基ーCR⁹ = CR¹⁰ーである化合物(3e)(R⁹及びR¹⁰は前記と同義である。)を合成するには、Wittig反応又はHornerーWadsworthーEmmons反応によってベンズアルデヒド誘導体又はアセトフェノン誘導体(12a)のカルボニル基からG¹を形成した後、末端シアノ基を同様にテトラゾリル基に変換し、保護基として4ーメトキシベンジル基又は2ー(トリメチルシリル)エトキシメチル基などを導入すればよい。G¹が基ー(C=O)ーまたは基ー(C=CHR⁸)ーである式(3e)の化合物は、R²⁰がNーメトキシーNーメチルカルバモイル基である化合物(12a)から合成できる(R⁸は前記と同義である。)。

【0043】R²⁰がNーメトキシーNーメチルカルバモイル基である化合物(12a)は対応するベンゾイルクロリドと、市販品を入手可能なN,Oージメチルヒドロキシルアミン塩酸塩とから公知の方法で容易に調製することができる。この化合物と文献記載の方法で製造した1ー(4ーメトキベンジル)ー1Hーテトラゾールとを、テトラヒドロフランなどの不活性エーテル系溶媒中でローブチルリチウムなどの有機アルキルリチウムとー100℃~室温の範囲の温度で処理し、ついで低温下に希塩酸などの希鉱酸または飽和塩化アンモニウム水溶液等で中和処理することにより化合物(3e)を調製できる。さらに、化合物(3)が有するカルボニル基を、種々のWittig反応試薬、またはHornerーWadsworthーEmmons反応試薬を用いて処理することにより、基ー(C=CHR⁸)ーを有する化合物

(3 e) を製造することができる。

【0044】G¹ が基-NR⁴ -である化合物 (3 e) (R⁴ は前記と同義である。) は、R²⁰が置換基を有す ることもあるアミノ基であるアニリン誘導体 (12a) を、プロムシアン等のシアノ化の試薬で基-NR⁴-C Nとした後、前記と同様にしてシアノ基のテトラゾール ・化と保護基の導入とを行うことにより製造することがで きる。また、G¹ が基-NR³ CO-である化合物(3 e) (R³ は前記と同義である。) は、R²⁰が置換基を 有することもあるアミノ基であるアニリン誘導体(12 a) を置換基を有することもあるシアノベンゾイルクロ リド誘導体と縮合してG¹の基-NR³CO-を形成し た後、同様にシアノ基のテトラゾール化と保護基の導入 とを行うことにより製造することができる。さらに、G ¹ が基-NR⁵ SO。-である化合物(3e)(R⁵ は 前記と同義である。) は、R²⁰が置換基を有することも あるアミノ基であるアニリン誘導体(12a)を置換基 を有することもあるシアノベンゼンスルフォニルクロリ ド誘導体と縮合してG¹の基-NR⁵SO₂ーを形成し た後、同様にシアノ基のテトラゾール化と保護基の導入 とを行うことにより製造することができる。

【0045】上記の反応で用いるアニリン誘導体(12a)は、市販品を入手可能であるか、又はニトロベンゼン誘導体の還元により容易に製造することが可能である。また、安息香酸誘導体をCurtius転位反応に付することによっても製造可能である。例えば、第3-プチルアルコール中で、またはさらにトルエンなどの不活性芳香族炭化水素系溶媒を組み合わせた混合溶媒中で、トリエチルアミンなどの有機アミン系塩基の存在下に安息香酸誘導体をジフェニルフォスフォリルアジド等の酸アジド化試薬と0℃から溶媒の沸点の範囲で、好ましくは室温から溶媒の沸点の範囲の温度で反応させることにより、Curtius反応成績体であるアシルアミノ体を得ることができる。このアシルアミノ体を塩酸またはトリフルオロ酢酸等の酸で処理することによってアニリン誘導体(12a)に導くことができる。

【0046】 置換基を有することもあるアルキル基をもつアルキルアニリン誘導体(モノ置換アニリン、12a)は、N, Nージメチルホルムアミドなどの不活性極性溶媒中で、一級アミンであるアニリン誘導体を炭酸カ

リウム等の塩基の存在下にプロモ酢酸エステル類等の活性ハライドと反応させることによって直接製造することが可能である。また、一級アミンであるアニリン誘導体を無水トリフルオロ酢酸を用いてトリフルオロアセチル化した後、炭酸カリウム等の塩基の存在下に置換基を有することもあるアルキルハライド、好ましくはイオド体と反応させ、さらに脱トリフルオロアセチル化を行うことによってもモノ置換アニリン誘導体(12a)を製造することが可能である。さらに、R²⁰が置換基を有することが可能である。さらに、R²⁰が置換基を有することもあるアルキル基で、その置換基が水酸基であるNーヒドロキシアニリン誘導体(12a)は、ニトロベンゼン誘導体を含水エタノール中で塩化アンモニウムの存在下に亜鉛末還元を行うことによって調製することができる。

【0047】G¹ が酸素原子または硫黄原子である化合 物(3a)は、R²⁰が-SH若しくは-OHであるベン ゼンチオール誘導体またはフェノール誘導体(12a) から合成できる。例えば、テトラヒドロフランなどの不 活性エーテル系溶媒中で、上記の1- (4-メトキベン ジル).-1H-テトラゾールを、臭素またはヨウ素の共 存下にリチウムジイソプロピルアミドまたはリチウムへ キサメチルジシラジドと-100℃~室温の範囲の温度 で処理することにより、5位に臭素またはヨウ素原子を 有する1-(4-メトキベンジル)-1H-テトラゾー ル誘導体を製造することができる。この5-ブロモー又 は5-イオド-1-(4-メトキベンジル)-1H-テ トラゾールを、N, N-ジメチルホルムアミドなどの不 活性極性溶媒中で、ベンゼンチオール誘導体またはフェ ノール誘導体(12a)と炭酸カリウムなどの無機塩基 またはトリエチルアミンなどの有機アミンの存在下に処 理して化合物 (3 d) を合成することができる。

[0049] [化9]

[スキーム 5]

L-A- $(G^1)_m$ -R²² L-A- $(G^1)_m$ -G²-Q

【0050】R²²が置換基を有することもあるエチニル 基であり、mが0であるエチニルベンゼン誘導体(1 3)から、G² がイソオキサゾリル基である化合物 (3) を合成することができる。原料化合物となるエチニルベンゼン誘導体(13)は、エチル・プロピオル酸とアリールハライド、好ましくはイオドベンゼン誘導体

とから、前記の有機パラジウム(0価又は2価)触媒を用いたカップリング反応によって製造することができる。トルエンなどの不活性炭化水素系溶媒中、またはテトラヒドロフランなどの不活性エーテル系溶媒中でアルキルニトロ化合物をイソシアン酸フェニルなどの脱水剤で処理してニトリルオキシドを生成させた後、このニトリルオキシドを上記エチニルベンゼン誘導体(13)と反応させることにより、 [2+3] 環化付加体であるイソオキサゾール誘導体(3f)を製造することができる。 R²²がアミノ基であり、mが0であるアニリン誘導体(13)から、G²がピリミジニル基である化合物(3f)は、N-(カルボメトキシ)-メトキシメチレンアセタミド誘導体とアニリン誘導体(13)とを、例えばトルエンまたはキシレンなどの高沸点炭化水素系溶媒中で、好ましくは100℃から溶媒の沸点の範囲の温

度で加熱してピリミジン環を形成させ、さらにシアノ基を上記の方法に従ってテトラゾリル基に変換することによって製造することができる。

【0052】 【化10】

[スキーム6]

$$R^{1}$$
 R^{23}
 $A-Q$
 R^{2}
 $A-Q$
 R^{2}
 $A-Q$
 R^{2}
 R

(1a) 【0053】市販品を入手可能であるか、それ自体が公 知または公知の方法で製造可能な2-ブロモチアゾール 誘導体(14) (例えば、公知のハロケトン類とチオ尿 素との脱水縮合により容易に得られる2-アミノチアゾ ール類から、文献記載の方法に従って、ジアゾニウム塩 を経由したSandmeyer反応によるプロム化によ って製造可能である)を、テトラヒドロフランなどの不 活性エーテル系溶媒中で、-78℃~室温、好ましくは -78~0℃の範囲の温度下に1.8~3等量のn-ブ チルリチウムなどのアルキルリチウムまたはメチルマグ ネシウムプロミド等のグリニャー試薬と処理するメタル 交換反応に付し、ついで、化合物(15)と、例えば-78~30℃の範囲、好ましくは0℃から室温の範囲の 低温下に反応させ、その後、0℃以下の温度で希塩酸な どの希鉱酸または飽和塩化アンモニウム水溶液等で中和 することにより、対応の2- (1-オキソエチル)チア

ゾール (16)を製造することができる。続いて、2- (1-オキソエチル)チアゾール (16)を1,2-二塩化エチレンなどの不活性ハロゲン化炭化水素系溶媒に溶解し、-10℃~室温の範囲の温度下にトリフェニルフォスフィンオキシド及びトリフルオロメタンスルフォン酸無水物を加え、この混合物を-10℃~溶媒の沸点の範囲、好ましくは室温から溶媒の沸点の範囲の温度で反応させることによって、目的のエチニルチアゾール (1b)を製造することができる。

【0054】 [スキーム7] には、化合物(17)から Qを完成させることによって式(1)の化合物を合成する方法を示した(スキーム中、 R^1 、 R^2 、A、 G^1 、 G^2 、m、n、及びQは前記と同義であり、 R^{24} はホルミル基、カルボキシル基、またはシアノ基を表す。)。 【化11】

(17)
【0055】 [スキーム7] に従って、R²⁴がシアノ基である化合物(17)からQがテトラゾリル基である化合物(1)を製造するには、 [スキーム1] に示した方法に従ってエチニルチアゾール(2) とアリールハライドとをカップリングさせてR²⁴がシアノ基である化合物(17)を製造した後、この化合物(17)をN,Nージメチルホルムアミドなどの不活性極性溶媒に溶解し、塩化アルミニウムなどのルイス酸の存在下でナトリウムアジドと0℃~溶媒の沸点の範囲の温度下に処理するか、またはピリジン若しくは2,6ールチジンのトリフルオロ酢酸塩、または塩化アンモニウムなどの四級アンモニウム塩及びナトリウムアジドと室温から溶媒の沸点

【0.0.5.6】式(1)の化合物は、[スキーム8] に示すように、 G^1 を完成することによっても製造することができる(スキーム中 R^1 R^2 n 及びOは前記

ができる(スキーム中、 R^1 、 R^2 、n、及びQは前記 と同義であり、mは1であり、 R^{25} はカルボキシル基、または置換基を有することもあるアミノ基を表し、 R^{26} は置換を有することもあるアミノ基、カルボキシル基、またはクロロスルフォニル基を表し、 R^{27} は水酸基また

はアルコキシ基を表す。)。 【0057】

の範囲で処理すればよい。

【化12】

[スキーム8]

【0058】R²⁵がカルボキシル基であり、Aがフェニル基である安息香酸誘導体(18)から、G¹が一CONR⁴ーであり(R⁴は前記と同義である。)、Qがテトラゾリル基である化合物(1b)を製造するには、[スキーム1]に示したカップリング反応に従って、イオド安息香酸エステルとエチニルチアゾールとをカップリングさせて安息香酸誘導体(18)を製造し、さらにエステル部をアルカリ加水分解した後、塩酸等の鉱酸を添加して中和処理すればよい。この安息香酸誘導体(18)を、塩化メチレンなどの不活性ハロゲン化炭化水素系溶媒、トルエンなどの不活性のイン化炭化水素系溶媒、テトラヒドロフランなどの不活性エーテル系溶媒、またはN、Nージメチルホルムアミドなどの不活性極性溶媒中で、1ーエチルー3ー(3ージメチルアミノプロピル)カル

ボジイミド塩酸塩、N, N'ージシクロヘキシルカルボジイミド、N, N'ーカルボニルジイミダゾール、又はそれらの同類物である縮合剤を用いて、一20℃~溶媒の沸点の範囲、好ましくは0℃~室温の範囲の温度下にR²⁶がアミノ基であるアミノ体(19)と反応させることにより、化合物(1b)を調製することができる。【0059】また、別法として、トルエンなどの不活性炭化水素系溶媒または塩化メチレンなどの不活性ハロゲン化炭化水素系溶媒中で、化合物(18)を塩化チオニルなどのクロル化剤及びその同類物を用いて室温から溶媒の沸点の範囲で反応させて化合物(18)の酸クロリド体を調製することができる。この酸クロリド体を、塩

化メチレンなどの不活性ハロゲン化炭化水素系溶媒、ト

ルエンなどの不活性炭化水素系溶媒、またはテトラヒド

ロフランなどの不活性エーテル系溶媒中で、必要に応じてトリエチルアミンまたはピリジンなどの有機塩基または酢酸ナトリウムなどの無機塩基の存在下で、市販品を入手可能であるか、または公知の方法で製造可能なアミノ誘導体(19)と-10℃~溶媒の沸点の範囲、好ましくは0℃~室温の範囲の温度下に反応させることにより、対応の化合物(1d)に変換することができる。

【0060】R²⁴が置換基を有することもあるアミノ基 であり、Aがフェニル基であるアニリン誘導体(18) から、G¹ が基-NR³ CO-または基-NR⁵ SO。 ーであり(R³ およびR⁵ は、前記と同義である。)、 n \vec{n} $\vec{0}$ $\vec{0$ は2以上の置換基を有することもあるフェニル基であ り、かつ、Qがテトラゾリル基である化合物(1b)を 製造することができる。原料化合物として用いるアニリ ン誘導体(18)は、ヨードーニトロ安息香酸とエチニ ルチアゾールとから、 [スキーム1] で示したカップリ ング反応を行った後、さらにニトロ基を公知の還元剤を 用いて還元することにより製造することができる。還元 剤として、例えば、塩化第1錫及びその同類物を用いる 場合は、エチルアルコールなどの不活性アルコール系溶 媒を用いて、0℃~溶媒の沸点の範囲で反応を行うこと ができる。また、錫や銅などの金属を還元剤として用い る場合には、希塩酸などの希釈した鉱酸、または希塩酸 等の鉱酸とジオキサンなどのエーテル系不活性溶媒との 混合溶媒中で、0℃~溶媒の沸点の範囲の温度下に反応 を行い、反応終了後、酸性溶液を弱アルカリ性にするこ とによってアニリン誘導体(18)を製造することがで きる。アニリン誘導体(18)と5-テトラゾールカル ボン酸誘導体(19) (nが0の場合)または安息香酸 誘導体(19) (nが1の場合)との縮合反応は、テト ラヒドロフランなどの不活性エーテル系溶媒、または N. Nージメチルホルムアミドなどの不活性極性溶媒中 で、1-エチル-3- (3-ジメチルアミノプロピル) カルボジイミド塩酸塩、N, N'ージシクロヘキシルカ ルボジイミド、N, N'ーカルボニルジイミダゾール、 又はそれらと同類物である縮合剤を用いて、−10℃~ 溶媒の沸点の範囲、好ましくは0℃~室温で行うことが でき、必要に応じて、例えばトリエチルアミンまたは4 ジメチルアミノピリジンなどの有機塩基または酢酸ナ トリウムなどの無機塩基の存在下に行うことができ、対 応の化合物(1b)を得ることができる。

【0061】別法として、アニリン誘導体(18)を、5-テトラゾールカルボン酸誘導体(19)(nが0の場合)、または安息香酸誘導体(19)(nが1の場合)とから導かれる酸クロリドと処理することにより、 G^1 の基-N R^3 CO-を完成させて化合物(1 b)に変換することができる。また、 G^1 が-N R^5 SO $_2$ - である化合物(1 b)は、塩化メチレンなどの不活性ハロゲン化炭化水素系溶媒、テトラヒドロフランなどの不

活性エーテル系溶媒、またはN, Nージメチルホルムアミドなどの不活性極性溶媒中で、アニリン誘導体(18)を、トリエチルアミンまたはピリジン等の有機アミン類の存在下に、それ自体公知であるか、または市販品を入手可能なアリールスルフォニル・クロリド(19)と縮合して得ることができる。

【0062】R²⁵が置換基を有することもあるアミノ基 である化合物(18)を、市販品を入手可能であるか、 または公知の方法で製造可能な環状酸無水物 (20)で アシル化することにより、化合物(1 c)を製造するこ ともできる。この方法は、化合物(1c)の G^1 、 G^2 、及びQを一挙に合成する方法である $[G^1]$ は基一 NR³ CO-であり、G² は基-CHR¹¹-CHR¹²-または基-CHR¹³=CHR¹⁴- (CR¹⁵=CR¹⁶) y -であり、Qはカルボキシル基である(R^3 、 R^{11} 、R¹²、R¹³、R¹⁴、R¹⁵、R¹⁶及びyは前記と同義であ る)]。このアニリン誘導体(18)と環状酸無水物 (20) とを、塩化メチレンなどの不活性ハロゲン化炭 化水素系溶媒、トルエンなどの不活性炭化水素系溶媒、 またはテトラヒドロフランなどの不活性エーテル系溶媒 中で、-10℃~溶媒の沸点の範囲の温度下に、必要に 応じてトリエチルアミンなどの不活性有機アミン又は酢 酸ナトリウムなどの不活性無機塩基の存在下で反応さ せ、ついで、例えば希塩酸等の鉱酸を用いて中和するこ とにより対応の化合物 (1 c) を得ることができる。別 法として、アニリン誘導体(18)とモノカルボン酸モ ノエステル類 (21) とを、塩化メチレンなどの不活性 ハロゲン化炭化水素系溶媒、テトラヒドロフランなどの 不活性エーテル系溶媒、またはN、N-ジメチルホルム アミドなどの不活性極性溶媒中で、N, N'ージシクロ ヘキシルカルボジイミド、N、N'-カルボニルジイミ ダゾール、又はそれらの同類物である縮合剤を用いて、 -20℃~溶媒の沸点の範囲、好ましくは0℃~室温で 縮合させ、ついで、エステルを加水分解することによっ て化合物(1c)を製造することができる。

【0063】式(1)で表される本発明の化合物は、強力なペプチドロイコトリエン拮抗作用、及びヒスタミンなどのメディエーターの遊離抑制作用を併せ持つことを特徴としており、医薬の有効成分として有用である。本発明の化合物からなる医薬は、例えば、ロイコトリエン 及び/又は肥満細胞から放出されるヒスタミンが関与する各種疾患、好ましくはロイコトリエンの発現過剰及び/又はヒスタミンの遊離過多に起因する各種疾患、例えば、気管支喘息、肺アナフィラキシー、嚢胞性線維症、慢性気管支炎、気管支拡張症、呼吸窮迫症候群、肺浮腫、乾鮮、腎炎、アレルギー性鼻炎、又はアトピー性皮膚炎などの治療及び/又は予防に有用である。また、脳虚血に起因する脳浮腫や脳血管顰縮、冠血流量減少による狭心症、又は肝炎などの治療及び/又は予防にも有用である。

【0064】本発明の化合物を医薬として用いる場合、遊離形態の化合物のほか、生理学的に許容される塩の形態の化合物を用いてもよい。式(1)の化合物が5-テトラゾリル基やカルボキシル基等の酸性基を有する場合、一般的に塩基付加塩を形成することが可能である。生理学的に許容される塩としては有機塩類又は無機塩類の何れでもよく、その好適な例として、例えば、リチウム塩、ナトリウム塩、若しくはカリウム塩等のアルカリ土類金属塩、アンモニウム塩若しくはカルシウムリエチルアミン塩、Nーメチルグルカミン塩、又はトリエチルアミン塩、Nーメチルグルカミン塩、又はトリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン塩等を挙げることができる。また、本発明の医薬としては、遊離形態の化合物若しくは塩の形態の化合物のほか、それらの水和物又は溶媒和物を用いてもよい。

【0065】式(1)の化合物若しくはその塩、又はそ れらの水和物若しくは溶媒和物を医薬としてヒトを含む 哺乳類に投与する場合、それらの物質自体を投与しても よいが、通常は、当業者に周知に方法に従って該物質を 有効成分として含む医薬組成物を調製して投与すること が好ましい。このような医薬組成物は経口的又は非経口 的に投与することができ、上記有効成分の物質以外に、 他の医薬の有効成分、例えば、抗ヒスタミン剤、キサン チン誘導体、ベータ (β) 刺激薬、又は抗喘息ステロイ ド剤 (例えばプレドニゾロン及びプレドニゾリン) など を配合することも可能である。経口投与に適する医薬組 成物の例としては、例えば、錠剤、散剤、顆粒剤、細粒 剤、カプセル剤、懸濁剤、溶液剤、シロップ剤、エリキ シル剤などを挙げることができる。非経口投与に適する 医薬組成物の例としては、例えば、静脈内注射剤、点滴 剤、直腸内投与用の座薬、点鼻剤、点耳剤、軟膏やクリ ーム剤などの局所外用薬、経皮吸収剤、経粘膜吸収剤、 エアロゾールや微細粉砕粉末または露状溶液の形態の吸 入剤などを挙げることができる。

【0066】経口投与に適する医薬組成物の製造には、 例えば、タルク、澱粉、乳糖、又は他の生理的に許容し 得る製剤用担体を用いることができ、さらに、糖または 他の甘味料、風味料、着色料、粘着剤、又はその他の製 剤用添加物を用いてもよい。非経口的投与の場合、従来 汎用の液状媒体、例えば、注射用蒸留水、緩衝液、落花 生油などを用いて、溶液剤又は懸濁剤などを調製するこ とができる。エアロゾールとして投与する場合、それら を適した生理的に許容し得る溶媒、例えばエチルアルコ ールまたは混和性溶媒の組み合わせ中に溶解し、生理的 に許容し得るプロペラントと混合することができる。エ アロゾール用の医薬組成物は、使用のために加圧組成物 の放出に適したエアロゾールバルブを付けた加圧容器に 包装することが好ましく、該容器には。一動作により所 定の有効投薬量の医薬組成物を放出できるような計量バ ルブが備えられていることが好ましい。本発明の医薬の 投与量及び投与頻度などの投与計画は特に限定されず、 投与すべき有効成分の物質の活性の力価と持続時間、投 与経路、及び治療及び/又は予防の対象となる動物の重 度、年齢などに応じて適宜選択することが可能である。 例えば、式(1)の化合物又はそれらの塩を含む医薬組 成物の経口投与量は、1回の投薬または数回に分けた投 薬として、1日当たり有効成分量として約0.1mg~ 2000mg、好ましくは約0.1mg~約500mg の範囲である。

【0067】なお、本発明の化合物の用途はそれ自体が 医薬活性を有する医薬に限定されることはなく、合成中 間体やプロドラッグとしても有用である。例えば、上記 の酸性基部分に置換基としてアルキル基、ベンジル基、 アルコキシアルキル基、及びフェニルアルキル基などを 有する化合物は合成中間体として有用である。また、酸 性基部分に置換基として、例えば、アセトキシメチル 基、ピバロイルオキシメチル基、エトキシカルボニル 基、ジメチルアミノエチル基、又は5ーインダニル基な どを有する化合物は、プロドラッグとして用いることも 可能である。

[0068]

【実施例】以下、実施例によりさらに具体的に説明する が、これらは本発明の例示のために記載したものであ り、本発明の範囲をなんら制限するものではない。実施 例中の [IR]、 [NMR] 及び [MS] の記号は、各 々 [赤外吸収スペクトル] 、 [核磁気共鳴スペクトル] 及び「質量分析」を意味する。クロマトグラフィーによ る分離の箇所に記載されている溶出溶媒の割合は体積比 を示す。 [IR] はKBr打錠法で測定したものであ る。 [NMR] は、 [¹ H] -NMRを意味し、括弧内 の溶媒は測定溶媒を示し、全て内部標準物質としてテト ラメチルシラン (TMS) を用いた。なお、周知のよう に、例えば5-テトラゾリル基、4-[1,2,3]-トリアゾリル基、及び5-[1,2,3]ートリアゾリ ル基は互変異性の水素原子を有している。便宜上、これ らの基についての実施例中の表示は、それぞれ1H-テ トラゾールー5-イル、1H-[1, 2, 3]-トリア ゾール-4-イル基、及び1H-[1, 2, 3]-トリ アゾールー5ーイル基)で表した。

【0069】 [参考例1] 4-シクロブチル-2-エ チニルチアゾール:

(工程1) エチル 4ーシクロプチルー2ーチアゾール カルボキシレートの合成

エチル チオオキザメート9g及びブロモメチルシクロプチルケトン11.96gをエタノール70m1中、2時間加熱還流した。冷却後、反応液を濃縮した。残渣に塩化メチレン200m1を加え、飽和炭酸水素ナトリウム、次いで飽和食塩水にて洗浄した。塩化メチレン層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、留去した。残留油状物をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出

液:n-ヘキサン:酢酸エチル=8:1) にて精製して 13.7gのエチル 4-シクロブチル-2-チアゾー ルカルボキシレートを淡黄色油状物として得た。

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3)$ $\delta \text{ ppm}$ 1. 4 3 (3H, t), 1. 88~2. 44 (6H, m), 3. 78 (1H, quint), 4. 48 (2H, q), 7. 23 (1H, s).

【0070】 (工程2) 4ーシクロプチルー2ーチアゾ ールメタノールの合成

エチル 4ーシクロブチルー2ーチアゾールカルボキシレート13.7gをエタノール60mlに溶解し、氷冷下に水素化ホウ素ナトリウム2.45gを徐々に加えた。反応液をさらに室温で8時間撹拌した。氷冷下、反応液に水を加え過剰の水素化ホウ素ナトリウムを分解した後、塩化メチレンにて抽出した。抽出液を飽和食塩水にて洗浄、無水硫酸ナトリウムにて乾燥した。溶媒を留去し、4ーシクロブチルー2ーチアゾールメタノール8.39gを淡褐色油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3)$ δppm 1. 8 $5\sim2$. 43 (6H, m), 3. 63 (1H, m), 3. 77 (1H, br), 4. 91 (2H, d), 6. 86 (1H, s).

【0071】(工程3)4-シクロブチルー2-チアゾ ールカルバアルデヒドの合成

a法)二塩化オキザリル43.2gを塩化メチレン350mlに溶解し、撹拌下-70℃でジメチルスルフォキシド(以下DMSOと略す。)53.1gを滴下した。滴下終了後、同温度でさらに0.5時間撹拌した。この溶液中に4-シクロプチルー2-チアゾールメタノール28.8gの塩化メチレン100ml溶液を同温度で滴下した。滴下終了後、さらに1時間後、トリエチルアミン103gを加えた。反応液を室温まで昇温した後、水100mlを加えエーテル500mlにて2回抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、得られた残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチル=8:1)にて精製し、4-シクロプチルー2-チアゾールカルバアルデヒド19.9gを淡黄色油状物として得た。

【0072】b法)4ーシクロブチルー2ーチアゾールメタノール 1.18g及び活性二酸化マンガン1.2 1gをトルエン50m1中、4時間加熱還流した。冷却後、不溶物をセライトを用い、減圧下にろ別した。ろ液を減圧留去し、得られた残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:nーヘキサン:酢酸エチル=8:1)にて精製し、4ーシクロブチルー2ーチアゾールカルバアルデヒド800mgを淡黄色油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.9$ 2~2. 48 (6H, m), 3. 76 (1H, m),

7. 35 (1H, s), 9. 99 (1H, s). 【0073】(工程4) 1,1-ジプロモー2ー(4 ーシクロプチルー2ーチアゾリル) エチレンの合成 四臭化炭素3.97gを塩化メチレン50mlに溶解 し、-10℃でトリフェニルフォスフィン6.27gを 加えた。この溶液中に 4ーシクロブチルー2ーチアゾ ールカルバアルデヒド1gの塩化メチレン5m1溶液を 同温度で滴下した。滴下終了後、反応液を室温に戻し た。反応液に飽和炭酸水素ナトリウムの水溶液を加えて 中和した後、クロロホルムにて抽出した。抽出液を無水 硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去して得られ る油状物をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィ - (溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1) にて 精製し1, 1-ジプロモー2-(4-シクロプチルー2 ーチアゾリル)エチレン1.9gを淡褐色油状物として 得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 1.8 9~2.41 (6H, m), 3.68 (1H, m), 7.02 (1H, s), 7.95 (1H, s).

【0074】 (工程5) 4ーシクロプチルー2ーエチ ニルチアゾールの合成

a法)1,1ージプロモー2ー(4ーシクロブチルー2ーチアゾリル)エチレン1.48gをテトラヒドロフラン(以下THFと略す。)20mlに溶解し、窒素気流下-70℃で撹拌下に、nープチルリチウム(1.5Mのnーへキサン溶液)6.1mlを滴下した。滴下終了後、反応液を同温度でさらに1時間撹拌した。飽和塩化アンモニウム水溶液50mlを反応液に加えた後、室温に戻した。反応液を酢酸エチルで2回抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られる油状物を、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:nーヘキサン:酢酸エチル=8:1)にて精製し、4ーシクロブチルー2ーエチニルチアゾール 546mgを淡褐色油状物として得た。

【0075】b法)ジイソプロピルアミン10.1gをTHF20mlに溶解し、窒素気流下-78℃で撹拌下に、n-ブチルリチウム(1.7Mのn-ヘキサン溶液)59mlを滴下した。反応液をさらに0℃で0.5時間撹拌した後、再び-78℃に冷却し、50mlのトリメチルシリルジアゾメタン(2Mのn-ヘキサン溶液)を内温-50℃以下に保ちながら滴下した。滴下終了後、反応液を-78℃で0。5時間撹拌した。その溶液に4-シクロブチル-2-チアゾールカルバアルデヒド15.8gのTHF100ml溶液を内温-50℃以下を保ちながら滴下した。反応液を-78℃で1時間撹拌した後、0℃で1時間、さらに室温で1時間撹拌した。反応液を300mlの氷及び飽和塩化アンモニウム水溶液中に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和

食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる油状物を、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチル=8:1)にて精製し、4-シクロプチルー2-エチニルチアゾール11.1gを淡褐色油状物として得た。NMR(400MHz,CDC 1_3) δ ppm 1.88~2.38(6H,m),3.44(1H,s),3.67(1H,m),6.93(1H,s).

【0076】 [参考例2] 2ーエチニルベンゾチアゾ ール

(工程1) 2-(2,2-ジブロモエテニル)ベンゾ チアゾールの合成

ベンゾチアゾールー2ーカルバルデヒド2.00gを参考例1の工程4と同様に処理し、nーヘキサンから結晶化させ2ー(2,2ージブロモエテニル)ベンゾチアゾール1.79gを結晶性粉末として得た。

融点 $102\sim103$ °C; NMR (400MHz, CD Cl₃) δ ppm 7. $44\sim7$. 48 (1H, m), 7. $50\sim7$. 54 (1H, m), 7. 9

 $0 \sim 7.92$ (1H, m), 8.06 (1H, s), 8.06 ~8.08 (1H, m).

【0077】 (工程2) 2-エチニルベンゾチアゾールの合成

2- (2, 2-ジブロモエテニル) ベンソチアソール 1.75gを参考例1の工程5のa法と同様に処理し、 生成物をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー (溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチル=10:1) にて 精製し、2-エチニルベンソチアソール0.63gを淡 褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p pm 7. 4 $5\sim7$. 49 (1H, m), 7. $51\sim7$. 55 (1H, m), 7. 86 ~7 . 88 (1H, m), 8. 07 \sim 8. 09 (1H, m).

【0078】 [参考例3] 4-n-プロピル-2-エ チニルチアゾール: 4-n-プロピル-2-カルバルデ ヒド1.36gを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、生成物をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液: n-ヘキサン: 酢酸エチル=10:1)にて精製し、4-n-プロピル-2-エチニルチアゾール0.73gを淡褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 0.9 6 (3H, t), 1.74 (2H, m), 3. 44 (2H, t), 6.92 (1H, s).

【0079】 [参考例4] 4ーシクロプロピルー2ーエチニルチアゾール:4ーシクロプロピルー2ーカルバルデヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4ーシクロプロピルー2ーエチニルチアゾール0.73gを淡褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 0.9

 $2\sim0.99$ (4H, m), 2.01 \sim 2.08 (1 H, m), 3.42 (1H, s), 6.88 (1H, s).

【0080】 [参考例5] 4-イソプロピルー2-エチニルチアゾール:4-イソプロピルー2-カルバルデヒド参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4-イソプロピルー2-エチニルチアゾールを淡褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 1. 3 2 (6H, d), 3. 31 (1H, m), 3. 44 (1H, s), 6. 92 (1H, s).

【0081】 [参考例6] 4-tert-ブチル-2 -エチニルチアゾール:4-tert-ブチル-2-カルバルデヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理 し、4-tert-ブチル-2-エチニルチアゾールを 油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 1. 3 6 (9 H, s), 3. 43 (1 H, s), 6. 9 4 (1 H, s).

【0082】 [参考例7] 4ーイソプロピルー5ーメチルー2ーエチニルチアゾール:4ーイソプロピルー5ーメチルー2ーカルバルデヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4ーイソプロピルー5ーメチルー2・一エチニルチアゾールを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 1. 2 7 (6H, d), 2. 38 (3H, s), 3. 06 (1H, m), 3. 39 (1H, s).

【0083】 [参考例8] 4ーシクロペンチルー2ーエチニルチアゾール: 4ーシクロペンチルー2ーカルバルデヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4ーイソプロピルー2ーエチニルチアゾールを淡褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.6 0~2.70 (8H, m), 3.21 (1H, m), 3.43 (1H, s), 6.92 (1H, s).

【0084】 [参考例9] 4-シクロヘキシル-2-エチニルチアゾール:4-シクロヘキシル-2-カルバルデヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4-シクロペンチル-2-エチニルチアゾールをプリズム晶として得た。

融点 $77\sim78\%$; NMR $(400MHz, CDC l_3)$ δ ppm $1.20\sim2.10$ (10H, m), 2.77 (1H, m), 3.42 (1H, s), 6.89 (1H, s); MS (EI) m /z 191 (M^+) ; 元素分析値 $C_{11}H_{13}NS$ の計算値 (%); C, 69.06; H, 6.85; N, 7.32, 測定値 (%); C, 68.91; H, 6.83; N, 7.14.

【0085】 [参考例10] 4-(メチルチオ) メチ

ルー2-エチニルチアゾール:4-(メチルチオ)メチルー2-カルバルデヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4-(メチルチオ)メチルー2-エチニルチアゾールを淡褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 2. 1 1 (3H, s), 3. 47 (1H, s), 3. 83 (2H, s), 7. 18 (1H, s). 【0086】[参考例11] 4-メトキシメチルー2

【00 8 6】 [参考例 1 1] 4 - メトキシメチルー 2 - エチニルチアゾール: 4 - メトキシメチルー 2 - カルバルデヒドを参考例 1 の工程 5 の b 法と同様に処理し、4 - メトキシメチルー 2 - エチニルチアゾールを淡赤褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 3. 4 7 (4H, s), 4.60 (2H, s), 7. 27 (1H, s).

【0087】[参考例12] 4-メチル-2-エチニルチアゾール:4-メチル-2-カルバルデヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4-メチル-2-エチニルチアゾールを淡褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 2. 4 7 (3H, s), 3. 44 (1H, s), 6. 92 (1H, s).

【0088】 [参考例13] 4ーイソブチルー2ーエチニルチアゾール:4ーイソブチルー2ーカルバルデヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4ーイソブチルー2ーエチニルチアゾールを淡褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 0.9 2 (6H, d), 2.08 (1H, m), 2. 64 (2H, d), 3.44 (1H, s), 6.90 (1H, s).

【0089】[参考例14] 4-エチル-2-エチニルチアゾール:4-エチル-2-カルバルデヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4-エチル-2-エチニルチアゾールを淡褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 1. 3 1 (3H, t), 2. 82 (2H, q), 3. 44 (1H, s), 6. 92 (1H, s).

【0090】 [参考例15] 4-n-オクチル-2- エチニルチアゾール: 4-n-オクチル-2-カルバル デヒドを参考例1の工程5のb法と同様に処理し、4-n-オクチル-2-エチニルチアゾールを淡黄色油状物 として得た。

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 0.8$ 7 $(3\text{H}, \text{t}), 1.26 \sim 1.74 (12\text{H}, \text{m}), 2.77 (2\text{H}, \text{t}), 3.43 (1\text{H}, \text{s}), 6.90 (1\text{H}, \text{s}).$

【0091】 [参考例16] 4-シクロプチルー2-(2-(3-ニトロフェニル) エチニル) チアゾール: 3-イオドニトロベンゼン519mg、ヨウ化第一銅4 0mg、テトラキス(トリフェニルフォスフィン)パラジウム [0] 120mgにジイソプロピルアミン10m 1を加え、窒素気流下、室温で撹拌下に4ーシクロプチルー2ーエチニルチアゾール340mgを加えた。反応液を室温でさらに1時間撹拌した。反応液を減圧留去して得られる油状物をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:nーヘキサン:酢酸エチル=8:1)にて精製し、4ーシクロプチルー2ー(2ー(3ーニトロフェニル)エチニル)チアゾール502mgを淡黄色微細針状晶として得た。

融点 107~109℃; IRvmax cm⁻¹ 152 8; NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1. $90\sim2$. 44 (6H, m), 3. 71 (1 quint), 7.02 (1H, s), 7. 57 (1H, t), 7. 89 (1H, t), 8. 24 (1H, ddd), 8. 44 (1H, t); MS (FAB) m/z 285 (M^++1). 【0092】[参考例17] 3-(2-(4-シクロ ブチルー2ーチアソリル) エチニル) アニリン:4ーシ クロブチルー2ー(2-(3-ニトロフェニル)エチニ ル) チアゾール500mg及び塩化錫(2水和物)1. 43gをエタノール10ml中、撹拌下に2時間加熱還 流した。冷却後、溶媒を留去した。得られる油状物に氷 冷下、4N水酸化ナトリウム水溶液を加えてアルカリ性 とした後、塩化メチレンで2回抽出した。合わせた塩化 メチレン層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウ ムにて乾燥した。溶媒を減圧留去して得られる油状物を シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出 液:クロロホルム:エチルアルコール=20:1) にて 精製し、3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリ ル) エチニル) アニリン410mgを淡褐色油状物とし て得た。

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.8$ $8 \sim 2.40 (6 \text{H}, \text{m}), 3.69 (1 \text{H}, quint), 6.71 (1 \text{H}, ddd), 6.89$ (1 H, t), 6.93 (1 H, s), 7.14 (1 H, t).

【0093】 [参考例18] エチル 3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) 安息香酸:エチル 3-ヨード安息香酸8.45g、テトラキス(トリフェニルフォスフィン) パラジウム [0] 1.77g及び4-シクロプチル-2-エチニルチアゾール5gをジイソプロピルアミン100ml中、窒素気流下、室温で1時間撹拌した。反応液を減圧留去して得られる油状物をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチル=8:1) にて精製し、エチル 3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) 安息香酸9.27gを淡褐色油状物として得た。

 $IR \nu \max cm^{-1} 2220$; NMR (400MH)

z, CDCl₃) δ p p m 1. 41 (3H, t), 1. 91~2. 42 (6H, m), 3. 70 (1 H, quint), 4. 40 (2H, q), 6. 97 (1H, s), 7. 46 (1H, t), 7. 75 (1H, dt), 8. 06 (1H, dt), 8. 28 (1H, t); MS (FAB) m /z 312 (M⁺+1).

【0094】 [参考例19] 3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) 安息香酸:エチル3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) 安息香酸9.28gをTHF100m1に溶解し、0.25N水酸化ナトリウム水溶液200m1を加え、室温で3時間撹拌した。反応液を氷冷撹拌下に1N塩酸100m1中に注いだ。析出した結晶を集め、水洗後、風乾した。得られた粗結晶をクロロホルム-n-ヘキサンから再結晶し、3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) 安息香酸6.85gを淡黄色微細針状晶として得た。

融点 $139\sim140$ ℃; $IRvmax cm^{-1} 222$ 0; $NMR (400MHz, CDCl_3) \delta ppm$ 1. $90\sim2$. 45(6H, m), 3.76(1H, quint), 6.97(1H, s), 7.50(1H, t), 7.80(1H, dt), 8.14(1H, dt), 8.38(1H, t); $MS (FAB) m/z 284(M^+ + 1)$; 元素分析値 $C_{16}H_{13}NO_2$ SO計算値(%) C, 67.82; H, 4.62; N, 4.94.

【0095】[参考例20] エチル 1-(4-メト キシベンジル) ーテトラゾールー5ーカルボキシレー ト、及び エチル 2- (4-メトキシベンジル) ーテ トラゾール-5-カルボキシレート:2,6-ルチジン 22mlに氷冷撹拌下に、トリフルオロ酢酸4mlを加 えた。反応液にアジ化ナトリウム3.25g及びシアノ ギ酸 エチル エステル4.82gを加え、70~80 ℃で5時間撹拌した。冷却後、反応液を酢酸得エチル1 00mlで希釈し、析出した結晶をろ取した。この結晶 をN, N-ジメチルホルムアミド20mlに懸濁し、炭 酸カリウム2.64g及び4-メトキシベンジル クロ リド6. 19gを加え、70~80℃で2時間撹拌し た。冷却後、反応液に水100m1を加え、トルエンで 抽出した。抽出液を水洗後、硫酸ナトリウムで乾燥し た。溶媒を留去して得られる残渣をシリカゲルを用いた カラムクロマトグラフィー (溶出液:n-ヘキサン:酢 酸エチル=2:1) にて精製し、1位:2位≒1:1の 混合物のエチル 1 and 2-(4-メトキシベン ジル) ーテトラゾールー5ーカルボキシレート11.7 gを油状物として得た。(両異性体はシリカゲルを用い たカラムクロマトグラフィーによって分離する事も可能 である。)

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1. 4 4 and 1. 45 (3H, each t), 3. 79 and 3. 80 (3H, eachs), 4. 51 and 4. 52 (2H, each q), 5. 78 and 5. 86 (2H, each s), 6. 86 and 6. 89 (2H, ea ch d), 7. 35 and 7. 38 (2H, each d).

【0096】 [参考例21] 1-(4-メトキシベンジル)ーテトラゾールー5ーカルボン酸、及び2-(4ーメトキシベンジル)ーテトラゾールー5ーカルボン酸:エチル 1-(4-メトキシベンジル)ーテトラゾールー5ーカルボキシレートと エチル 2-(4-メトキシベンジル)ーテトラゾールー5ーカルボキシレートの混合物0.77gに1N水酸化ナトリウム水溶液3.5m1及びメタノール15m1を加え、室温で1時間撹拌した。反応液を濃縮し、残渣に1N塩酸5m1を加え、酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得られた残渣にエーテルーnーへキサンを加え、析出した結晶を集め、1位:2位≒1:1の混合物の表題物0.45をプリズム晶として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 3.8 0 and 3.82 (3H, each s), 5.53 and 5.79 (2H, each s), 6.89 and 6.92 (2H, each d), 7.27and 7.38 (2H, each d), 8.12 and 8.58 (1H, each s).

【0097】 [実施例1] 5-(3-(2-(4-シ クロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 3ーイオドベンゾニトリルの合成

3ーイオドベンズアミド10.38gを50mlのDM Fに溶解し、0℃で撹拌下に、4.7mlのオキシ塩化 リンを滴下した。同温度で1時間撹拌後、反応液を50 0mlの氷水に注いだ。析出した結晶をろ取し、水洗し た後、乾燥して3ーイオドベンゾニトリル9.23gを プリズム晶として得た。

融点 $35\sim37$ °C; NMR (400MHz, CDC l_3) δ ppm 7.22(1H, t), 7.64 (1H, dt), 7.95(1H, dt), 7.99 (1H, t).

【0098】 (工程2) 3- (イオドフェニル)-1 H-テトラゾールの合成

アジ化ナトリウム33.35gをDMF150m1に懸 濁し、0℃で撹拌下に塩化アルミニウム15.20gを 徐々に加え、室温で1時間撹拌した。反応液に8.70 gの3-ヨードベンゾニトリルを加え、90℃で3時間 撹拌した。冷却後、反応液を氷冷撹拌下に、1 N塩酸3 00m1に注いだ。析出した結晶をろ取、水洗後、乾燥した。粗結晶をクロロホルムーエタノールーnーヘキサンから再結晶し、3 - (イオドフェニル) - 1 Hーテトラゾール9.34gを針状晶として得た。

融点 170~172℃; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm7. 42 (1H, dd), 7. 96 (1H, d), 8. 06 (1H, d), 8. 39 (1H, s); MS (FAB) m/z 273 (M⁺+1); 元素分析値C₇ H₅ I N₄ の計算値(%) C, 30. 90; H, 1. 85; N, 21. 59, 測定値(%) C, 30. 56; H, 1. 89; N, 20. 69.

【0099】(工程3) 5-(3-イオドフェニル) -2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール の合成

3- (イオドフェニル) -1H-テトラゾール8.98 g及び炭酸カリウム6.91gを50mlのDMFに懸濁し、氷冷撹拌下に4-メトキシベンジル クロリドを滴下した。滴下終了後、反応液を室温で15時間撹拌した。反応液を300mlの水に注いぎ、析出した結晶をろ取、水洗後、乾燥した。得られた粗結晶をクロロホルム-n-ヘキサンから再結晶して5- (3-イオドフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール11.43gを得た。

NMR $(400 \, \text{MHz}, \, \text{CDCl}_3)$ $\delta \, \text{ppm}$ 3.8 $0 \, (3\, \text{H}, \, \text{s})$, 5.73 $(2\, \text{H}, \, \text{s})$, 6.90~6.92 $(2\, \text{H}, \, \text{m})$, 7.20 $(1\, \text{H}, \, \text{t})$, 7.37~7.39 $(2\, \text{H}, \, \text{m})$, 7.78 $(1\, \text{H}, \, \text{dt})$, 8.10 $(1\, \text{H}, \, \text{dt})$, 8.48 $(1\, \text{H}, \, \text{t})$; MS $(F\, \text{AB})$ m/z 393 $(M^+ \, +1)$; 元素分析値 $C_{15}H_{13}I\, N_4\, O\mathcal{O}$ 計算値 (%) C,45.94; H,3.34; H,3.35; N,14.27.

【0100】(工程4) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2 -(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール23.53g、テトラキス(トリフェニルフォスフィン)[0]パラジウム3.47g及びヨウ化第一銅1.14gにジイソプロピルアミン100ml及びDMF50mlを加え、窒素気流下、室温で0.5時間撹拌した。この反応液に11.43gの4-シクロブチルー2-エチニルチアゾールのDMF溶液50mlを滴下し、さらに室温で2時間撹拌した。反応液を1000mlの酢酸エチルで希釈し、順次、1N塩酸、飽和食塩水で洗浄した後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得られた残渣を、シリカゲルを

用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:酢酸エチル:n-ヘキサン=1:8)にて精製し、n-ヘキサンより結晶化させ5-(3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール18.86gのを結晶性粉末として得た。

融点 $87\sim89^\circ C$; NMR $(400MHz, CDC l_3)$ δ ppm $1.90\sim2.42$ (6H, m), $3.66\sim3.75$ (1H, m), 3.80 (3H, s), 5.74 (2H, s), $6.90\sim6.92$ (2H, m), 6.97 (1H, s), $7.39\sim7.41$ (2H, m), 7.48 (1H, t), 7.65 (1H, d), 8.16 (1H, d), 8.37 (1H, s); MS (EI) m/z 427 (M^+) ; 元素分析値 $C_{24}H_{21}N_5$ OSの計算値 (%) C, 67.43; H, 4.95; N, 16.38, 測定値 (%) C, 67.21; H, 5.02; N, 16.27.

【0101】(工程5) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1 H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール17.96gをアニソール8ml及びトリフルオロ酢酸40mlに溶解し、室温で14時間、60℃で2時間撹拌した。反応液を500mlの氷水に注ぎ析出した結晶をろ取、水洗した後乾燥した。得られた粗結晶をクロロホルムーエタノールーnーヘキサンから再結晶し11.01gの表題物を結晶性粉末として得た。

融点 $190\sim193$ °C; $IRvmax cm^{-1} 222$ 0; $NMR (400MHz, DMSO-d_6) \delta pp$ m 1. $84\sim2$. 35(6H, m), 3. $64\sim3$. 73(1H, m), 7. 57(1H, s), 7. 73(1H, t), 7. 88(1H, d), 8. 16(1H, d), 8. 29(1H, s); $MS(EI) m/z 307(M^+)$; 元素分析值 $C_{16}H_{13}N_5$ S O 計算值(%) C, 62. 52; H, 4. 26; N, 22. 78, 測定值(%) C, 62. 33; H, 4. 35; N, 2. 2. 62.

【0102】 [実施例2] 5-(3-(2-(2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) メチル 3-(1H-テトラゾール-5-イル)フェニルアセテートの合成メチル 3-シアノフェニルアセテート3.10gを実施例1の工程2と同様に処理し、得られた粗結晶をエタノール-n-ヘキサンから再結晶し、メチル3-(1H-テトラゾール-5-イル)フェニルアセテート1.7

2gを針状晶として得た。

融点 $141\sim142$ °C; $IRvmax cm^{-1} 173$ 2; $NMR (400MHz, DMSO-d_6) \delta pp$ m 3. 68 (3H, s), 3. 77 (2H, s), 7. $44\sim7$. 55 (2H, m), 7. $95\sim8$. 00 (2H, m); 元素分析值 $C_{10}H_{10}N_4$ O_2 の計算値 (%) C, 55. 04; H, 4. 62; N, 25. 68, 測定値 (%) C, 55. 08; H, 4. 64; N, 25. 78.

【0103】(工程2) メチル 3-(2-(4-メ トキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フ ェニルアセテートの合成

メチル 3-(1H-テトラゾールー5-イル) フェニルアセテート1. 67gを実施例1の工程3と同様に処理し、メチル 3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル) フェニルアセテート2. 06gを油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 3.7$ 0 (3H, s), 3.75 (2H, s), 3. 79 (3H, s), 5.73 (2H, s), 6.89 (2H, d), 7.38 (2H, d), $7.40 \sim 7.45 (3H, m), 8.05 (1H, d).$

【0104】(工程3) 2-(4-メトキシベンジ ル) -5- (3-(2-オキソー2-(2-チアゾリ ル) エチル) -2H-テトラゾールの合成 2-プロモチアゾール2.25gをTHF30mlに溶 解し、氷冷撹拌下に、臭化マグネシウム ブロミド (0.95MのTHF溶液) 15mlを加えた。室温で 1時間撹拌した後、再び0℃に冷却し、3-(2-(4 ーメトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イ ル) フェニルアセテート2.00gのTHF10ml溶 液を滴下した。室温で1時間撹拌した後、1 N塩酸を加 え、酢酸エチルにて抽出した。抽出液を水、飽和食塩水 で洗浄した後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去 して得られる残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマト グラフィー(溶出液:酢酸エチル:n-ヘキサン=1: 4) にて精製し、得られる結晶をエーテルーn-ヘキサ ンから再結晶して、2-(4-メトキシベンジル)-5 - (3 - (2 - オキソー2 - (2 - チアゾリル) エチ ル) -2H-テトラゾール1.81gを針状晶として得

融点 80~81℃; IRνmax cm⁻¹ 1678; NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 3.80 (3H, s), 4.54 (2H, s), 6.89 (2H, d), 7.38 (2H, d), 7.39~7.46 (2H, m), 7.70 (1H, d), 8.04 (1H, d); 元素分析値C₂₀H₁₇N₅O₂ Sの計算値 (%) C, 61.37; H, 4.38; N, 17.89, 測定値 (%) C, 6

1. 11; H, 4. 51; N, 17. 82. 【0105】(工程4) 2-(4-メトキシベンジ ル) 5-(3-(2-(2-チアゾリル) エチニル) フ ェニル) -2H-テトラゾールの合成 トリフェニルフォスフィン オキシド1.56gに1, 2-ジクロロエタン15mlを加え、氷冷撹拌下に、ト リフルオロメタンスルフォン酸無水物 0.80gを加 え、同温度で15分撹拌した。反応液に、トリエチルア ミン1.2m1及び2-(4-メトキシベンジル)-5 - (3-(2-オキソー2-(2-チアゾリル) エチ ル) -2H-テトラゾール0. 73gを加え、20時間 加熱還流した。冷却後、反応液をクロロホルム50ml で希釈し、順次、1N塩酸、水で洗浄後、硫酸ナトリウ ムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残渣をシリカゲ ルを用いたカラムクロマトグラフィー (溶出液:酢酸エ チル:n-ヘキサン=1:3) にて精製し、得られた結 晶をクロロホルムーエーテルから再結晶して、2-(4) ーメトキシベンジル) -5-(3-(2-(2-チアゾ リル) エチニル) フェニル) -2H-テトラゾール0. 21gを針状晶として得た。

融点 95~96℃; IRvmax cm⁻¹ 2216; NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 3.80 (3H, s), 5.73 (2H, s), 6.91 (2H, d), 7.36~7.43 (3H, m), 7.49 (1H, t), 7.67 (1H, ddd), 7.88 (1H, d), 8.18 (1H, ddd), 8.37 (1H, dd); 元素分析値C₂₀H₁₅N₅ OSの計算値 (%) C, 64.33; H, 4.05; N, 4.05, 測定値 (%) C, 64.23; H, 4.19; N, 18.79.

【0106】(工程5) 5-(3-(2-(2-チア ゾリル) エチニル) フェニル) -1H-テトラゾールの 合成

2-(4-メトキシベンジル)-5-(3-(2-(2-fry))ル) エチニル) フェニル)-2H-テトラゾール<math>1.50 mgを実施例1の工程5と同様に処理し、得られた粗結晶をエタノールーエーテルから再結晶して表題物30 mgを結晶性粉末として得た。

融点 $174\sim175$ °C; $IRvmax cm^{-1}$ 2216; $NMR (400MHz, DMSO-d_6) \delta ppm 7.75 (1H, s), 7.88 (1H, d), 7.99 (1H, d), 8.02 (1H, d), 8.17 (1H, d), 8.39 (1H, s); 元素分析値<math>C_{12}H_7 N_5 SO$ 計算値 (%) C,56.90; H,2.79; N,27.65, 測定値 (%) C,57.14; H,2.87; N,26.84.

【0107】 [実施例3] 5-(3-(2-(2-ベンゾチアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-テトラ

ゾール:

(工程1) 2-(2-(3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニル)エチニル)ベンゾチアールの合成

2-エチニルベンゾチアゾール318mg及び5-(3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール784mgを実施例1の工程4と同様のカップリング反応に付し、nーヘキサンから結晶化させ2-(2-(3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニル)エチニル)ベンゾチアール468mgを淡褐色結晶性粉末として得た。

融点 $133\sim135$ °C; NMR (400MHz, C) DCl₃) δ ppm 3.80 (3H, s), 5.75 (2H, s), 6.90 \sim 6.93 (2H, m), 7.39 \sim 7.43 (2H, m), 7.47 (1H, t), 7.50 \sim 7.56 (2H, m), 7.71 (1H, d), 7.89 (1H, d), 8.09 (1H, d), 8.20 (1H, d), 8.42 (1H, s).

【0108】 (工程2) 5-(3-(2-(2-ベン ゾチアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-テトラゾ ールの合成

2-(2-(3-(2-(4-メトキシベンジル)-2 H-テトラゾール-5-イル)フェニル)エチニル)ベンゾチアゾール423mgを実施例1の工程5と同様に脱4-メトキシベンジル化反応を行い、粗結晶をクロロホルム-エタノールから再結晶し、表題物を得た。

融点 208~210℃; NMR (400MHz, D MSO-d₆) δppm7. 56~7. 65 (2H,

m), 7.75 (1H, t), 7.94 (1H, d), 8.11 (1H, d), 8.19 \sim 8.21 (2H, m), 8.36 (1H, s); MS (FAB) m/z 304 (M $^+$ +1); 元素分析 値C₁₆H₉ N₅ S·1/4H₂ Oの計算値(%) C, 62.43; H, 3.11; N, 22.75, 測定値(%) C, 62.60; H, 3.00; N, 22.56.

【0109】 [実施例4] 5-(3-(2-(4-n-プロピル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-(2-(4-n-プロピルー2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メト キシベンジル) -2H-テトラゾールの合成

4-n-プロピルー2-エチニルチアゾール及び5-(3-14 ドフェニル) -2-(4-14 ドランベンジル) -2 Hーテトラゾールを用い、実施例10 工程15 と同様に処理し、15 - (3-(2-(4-11 ープロピルー12 - チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-14 トキシベンジル) -2 Hーテトラゾールを淡黄色針状結

晶として得た。

融点 $57\sim58$ °C; NMR $(400MHz, CDC l_3)$ δ ppm 0.98 (3H, t), 1.77 (2H, m), 2.79 (2H, t), 3.84 (3H, s), 5.74 (2H, s), 6.9 1 (2H, d), 6.96 (1H, s), 7.41 (2H, d), 7.48 (1H, t), 7.65 (1H, dt), 8.16 (1H, dt), 8.36 (1H, t); 元素分析値 $C_{23}H_{21}N_5$ OS・ $1/4H_2$ Oの計算値 (%) C, 65.77; H, 5.16; N, 16.67, 測定値 (%) C, C, 66.21; H, 5.15; N, 16.30.

【0110】(工程2) 5-(3-(2-(4-n-プロピル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1 H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-n-プロピル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様処理し、得られた粗結晶を水-エタノールから再結晶し、表題物を結晶性粉末として得た。

融点 $154\sim156$ °C; NMR (400 MHz, D MSO- d_6) δ ppm0. 93(3 H, t), 1. 70(2 H, m), 2. 74(2 H, t), 7. 52(1 H, s), 7. 71(1 H, t), 7. 84(1 H, d), 8.16(1 H, d), 8.28(1 H, s); 元素分析値 C_{15} H $_{13}$ N $_5$ Sの計算値(%) C, 61.00; H, 4. 44; N, 23. 71, 測定値(%) C, 61. 01; H, 4. 48; N, 23. 55. 【0111】 [実施例5] 5-(3-(2-(4-)2) 2-(2-(4-)2)

(工程1) 5-(3-(2-(4-シクロプロピルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成4-シクロプロピルー2-エチニルチアゾール1.04g及び5-(3-イオドフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール2.73gを、実施例1の工程5と同様に処理し、2.13gの5-(3-(2-(4-シクロプロピル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを針状晶として得た。

-1H-テトラゾール:

融点 $106\sim107$ °C; NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 0. $94\sim0$. 99 (4H, m), 2. $04\sim2$. 11 (1H, m), 3. 8 0 (3H, s), 5. 74 (2H, s), 6. 91 (1H, s), 6. $89\sim6$. 93 (2H, m), 7. 40 (2H, d), 7. 47 (1H, t), 7. 65 (1H, dd), 8. 15 (1

dd), 3.35 (1H, t); MS (F H, AB) m/z 414 (M^+) . 【0112】(工程2) 5-(3-(2-(4-シク ロプロピルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) ー 1H-テトラゾールの合成 5-(3-(2-(4-シクロプロピル-2-チアゾリ ル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジ ル) -2H-テトラゾール2.07gを、実施例1の工 程5と同様に処理し、得られた粗結晶をクロロホルムー n-ヘキサンから再結晶し表題物1.16gを針状晶と して得た。 融点 184~185℃ (decomp.); IRv max cm⁻¹ 2216; NMR (400MHz, DMS $O-d_6$) δppm 0. $84\sim0$. 90 (2H, m), $0.92\sim0.98(1H, m)$, 2.0 $9\sim2.19$ (1H, m), 7.54 (1H, s), 7.72 (1H, t), 7.86 (1H, d), 8.16 (1H, d), 8.28 (1 H, s); MS (FAB) m/z 294 (M^+ + 1) ; 元素分析値C₁₅H₁₁N₅ S・1/2H₂ Oの計 算值(%) C, 59.59; H, 4.00; N, 23.16, 測定値(%) C,59.75; H, 3.80; N, 23.02. 【0113】 [実施例6] 5-(3-(2-(4-イ ソプロピルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) ー 1H-テトラゾール: (工程1) 5-(3-(2-(4-イソプロピル-2 −チアゾリル) エチニル) フェニル) −2−(4−メト キシベンジル) -2H-テトラゾールの合成 4-イソプロピル-2-エチニルチアゾール850mg 及び5-(3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシ ベンジル) -2H-テトラゾール2.55gを、実施例 1の工程5と同様に処理し、シリカゲルを用いたカラム クロマトグラフィー (溶出液:酢酸エチル:n-ヘキサ $\nu = 1:8$) にて精製し、5-(3-(2-(4-4))プロピルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2 - (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール1. 08gを淡褐色油状物として得た。 NMR (400MHz, CDC1 $_3$) δ ppm 1. 3 d), 3.16(1H, m), 81 (3H, s), 5.74 (2H, s), 6.91 (2H, dt), 6.96 (1H, d), 7.41 (2H, dt), 7.48 (1 t), 7.66 (1H, dt), 8.16 (1H, dt), 8.37 (1H, t). 【0114】(工程2) 5-(3-(2-(4-イソ

プロピルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) ー1

5-(3-(2-(4-イソプロピル-2-チアゾリ

ル) エチニル) フェニル) -2- (4-メトキシベンジ

Hーテトラゾールの合成

ル) -2H-テトラゾール1.85gを、実施例1の工 程5と同様に処理し、得られた粗結晶をクロロホルムー イソプロピリエーテルから再結晶して表題物383mg を淡褐色結晶性粉末として得た。 融点 177~179℃; NMR (400MHz, D $MSO-d_6$) $\delta ppm1.44$ (6H, 3. 25 (1H, m), 7. 70 (1H, s), t), 8. 03 (1H, 7.88 (1H, 8. 32 (1H, d), 8. 45 (1H, s) ; 元素分析値C₁₅H₁₃N₅ Sの計算値(%) C, 61.00; H, 4.44; N, 23.71, 測定値(%) C, 61.05; H, 4.54; N, 23.88. 【0115】 [実施例7] 5-(3-(2-(4-t ertープチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニ ·ル) -1H-テトラゾール: (工程1) 5-(3-(2-(4-tert-プチル -2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2- (4-メトキシベンジル) - 2 H - テトラゾールの合成 4-tert-ブチル-2-エチニルチアゾール402 mg及び5-(3-イオドフェニル)-2-(4-メト キシベンジル) -2H-テトラゾール2.73gを、実 施例1の工程5と同様に処理し、シリカゲルを用いたカ ラムクロマトグラフィー (溶出液:酢酸エチル:n-ヘ キサン=1:10) にて精製し、n-ヘキサンから結晶 化させ、5-(3-(2-(4-tert-プチル-2 ーチアプリル) エチニル) フェニル) -2- (4-メト キシベンジル) -2H-テトラゾール1.91gを得 融点 113~115℃; NMR (400MHz, C DCl_3) δppm 1. 39 (9H, s), 3. 80 (3H, s), 5.74 (2H, s), 6. 91 (2H, d), 6. 98 (1H, s), 7. 40 (2H, d), 7. 48 (1H, t), 7. 66 (1H, dt), 8. 16 (1H, d t), 8.37 (1H, t); MS (FAB) m /z 430 (M⁺ +1). 【0116】(工程2) 5-(3-(2-(4-te rtーブチルー2ーチアソリル) エチニル) フェニル) -1Hーテトラゾールの合成 5- (3- (2- (4-tert-ブチル-2-チアゾ リル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベン ジル) -2H-テトラゾール1.73gを、実施例1の 工程5と同様に処理し、得られた粗結晶をクロロホルム - IPEから再結晶して表題物1.06gを針状晶とし て得た。 融点 176~178℃; NMR (400MHz, D

 $MSO-d_6$) $\delta ppm1.33(9H, s),$

s), 7.73(1H, t),

d), 8.17(1H, d),

7. 54 (1H,

7.88 (1H,

8. 30(1H, s); MS(FAB) m/z $310(M^++1)$; 元素分析値 $C_{16}H_{15}N_5$ S・1 $/5H_2$ Oの計算値(%) C, 61. 22; H, 4. 98; N, 22. 31, 測定値(%) C, 6 1. 27; H, 4. 87; N, 22. 14. 【0117】[実施例8] $5-(3-(2-(4-7))^2)^2$ 【20117】 「実施例8] $5-(3-(2-(4-7))^2)^2$ 【20117】 「大きにより、エチニル)フェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-(2-(4-4)) 7 ロピルー5 - メチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) - 2 - (4-メトキシベンジル) - 2 H - テトラゾールの合成

4ーイソプロピルー5ーメチルー2ーエチニルチアゾール240mg及び5ー(3ーイオドフェニル)ー2ー(4ーメトキシベンジル)ー2Hーテトラゾール471mgを、実施例1の工程5と同様に処理し、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:酢酸エチル:nーヘキサン=1:8)にて精製し、nーヘキサンから結晶化させ、5ー(3ー(2ー(4ーイソプロピルー5ーメチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニル)ー2ー(4ーメトキシベンジル)ー2Hーテトラゾール1.91gを針状晶として得た。

融点 $101\sim103$ °C; NMR (400MHz, C) DCl₃) δ ppm 1. 31 (6H, d), 2. 41 (3H, s), 3. 09 (1H, m), 3. 80 (3H, s), 5. 74 (2H, s), 6. 91 (2H, d), 7. 40 (2H, d), 7. 46 (1H, br t), 7. 64 (1H, d), 8. 14 (1H, d), 8. 35 (1H, s).

【0118】(工程2) 5-(3-(2-(4-4)) プロピルー5-メチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1 Hーテトラゾールの合成 5-(3-(2-(4-4)) プロピルー5-メチル2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2 Hーテトラゾール387 mgを、実施例1の工程5 と同様に処理し、得られた粗結晶をクロロホルム-nーへキサンから再結晶し、表題物206 mgを結晶性粉末として得た。

融点 $153\sim155$ ℃; NMR $(400MHz, DMSO-d_6)$ δ pp m 1. 22 (6H, d), 2. 43 (3H, s), 3. 14 (1H, m), 7. 71 (1H, br t), 7. 86 (1H, d), 8. 15 (1H, d), 8. 27 (1H, s); MS (FAB) m/z 310 $(M^+ + 1)$; 元素分析値 $C_{16}H_{15}N_5$ Sの計算値 (%) C, 62. 11; H, 4. 89; N, 22. 64, 測定値 (%) C, 61. 99; H, 4. 92; N, 22. 86.

【0119】 [実施例9] 5-(3-(2-(4-シ

クロペンチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) ー1H-テトラゾール :

(工程1) 5-(3-(2-(4-シクロペンチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成4-シクロペンチルー2-エチニルチアゾール249mg及び5-(3-イオドフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール500mgを、実施例1の工程5と同様に処理し、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:酢酸エチル:n-ヘキサン=1:8) にて精製し、5-(3-(2-(4-シクロペンチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール420mgを淡褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.65~2.85(8H, m), 3.24(1H, m), 3.80(3H, s), 5.74(2H, s), 6.91(2H, d), 6.96(1H, s), 7.40(2H, d), 7.48(1H, t), 7.64(1H, dt), 8.15(1H, dt), 8.37(1H, t).

【0120】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロペンチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)ー1H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-シクロペンチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール400mgを、実施例1の工程5と同様に処理し、得られた粗結晶をクロロホルムーエタノール-n-ヘキサンから再結晶し表題物280mgを微細針状晶として得た。

融点 145°C (decomp.); NMR (400 MHz, CDCl₃-DMSO-d₆) δ ppm 1. 60~2. 75 (8H, m), 3. 25 (1H, m), 7. 00 (1H, s), 7. 54 (1H, t), 7. 71 (1H, d), 8. 17 (1H, d), 8. 37 (1H, s); MS (EI) m/z 321 (M⁺).

【0121】 [実施例10] 5-(3-(2-(4-シクロヘキシル-2-チアゾリル) エチニル) フェニ ル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-(2-(4-シクロへキシルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成4-シクロへキシルー2-エチニルチアゾール268mg及び5-(3-イオドフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール500mgを、実施例1の工程5と同様に処理し、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:酢酸エチル:n-ヘキサン=1:8) にて精製し、5-(3-(2-(4-シクロヘキシル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-

(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール400 mgを淡褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1. 2 5~2. 15 (10H, m), 2. 81 (1H, m), 3. 81 (1H, s), 5. 74 (2H, s), 6. 92 (2H, d), 6. 93 (1 H, s), 7. 41 (2H, d), 7. 65 (1H, dt), 8. 15 (1H, dt), 8. 36 (1H, t).

【0122】 (工程2) 5-(3-(2-(4-シクロヘキシル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-シクロヘキシル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール473mgを、実施例1の工程5と同様に処理し、得られた粗結晶をクロロホルムーエタノール-n-ヘキサンから再結晶し、表題物240mgを微細針状晶として得た。

融点 $166\sim169$ ℃; $IRvmax cm^{-1}$ 2216; $NMR (400MHz, CDCl_3) \delta ppm$ 1.25 \sim 2.20(10H, m), 2.96(1H, m), 7.05(1H, s), 7.55(1H, dd), 8.15(1H, s), 8.16(1H, dd); MS (EI) m/z 335(M^+); 元素分析値 $C_{18}H_{17}N_5 S$ の計算値(%) C, 64.45; H, 5.11; N, 20.88, 測定値(%) C, 64.46; H, 5.10; N, 20.62.

【0123】 [実施例11] 5-(3-(2-(4-メチルチオメチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニ ル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 2-(4-メトキシベンジル)-5-(3-(2-(4-メチルチオメチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2H-テトラゾールの合成2-エチニルー4-メチルチオチアゾール508mg及び5-(3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール981mgを実施例1の工程4と同様のカップリング反応に付し、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:酢酸エチル:n-ヘキサン=1:4)にて精製し、クロロホルムーn-ヘキサンから再結晶し2-(4-メトキシベンジル)-5-(3-(2-(4-メチルチオメチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2H-テトラゾール867mgを淡黄色結晶性粉末として得た。

融点 $104 \sim 106 \, \text{C}$; NMR $(400 \, \text{MHz}, \, \text{C})$ DCl₃) δ p p m 2. 14 $(3 \, \text{H}, \, \text{s})$, 3. 81 $(3 \, \text{H}, \, \text{s})$, 3. 86 $(2 \, \text{H}, \, \text{s})$, 5. 74 $(2 \, \text{H}, \, \text{s})$, 6. $90 \sim 6$. $93 (2 \, \text{H}, \, \text{m})$, 7. $21 (1 \, \text{H}, \, \text{s})$, 7. $39 \sim 7$. $41 (2 \, \text{H}, \, \text{m})$, 7. $49 (1 \, \text{H}, \, \text{t})$,

7. 65 (1H, d), 8. 17 (1H, 8. 36 (1H, s); MS (EI) m/z 4 33 (M⁺) ; 元素分析値C₂₂H₁₉N₅ S₂の計算値 (%) C, 60. 95; H, 4. 42; N, 1 6.15, 測定値(%) C,60.66; H, 4. 45; N, 16. 10. 【0124】(工程2) 5-(3-(2-(4-メチ ルチオメチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-テトラゾールの合成 2-(4-メトキシベンジル) -5-(3-(2-(4ーメチルチオメチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェ ニル) -2H-テトラゾール433mgを実施例1の工 程5と処理し、粗結晶をクロロホルムーnーヘキサンか ら再結晶し、表題物285mgを得た。 融点 159~162℃; NMR (400MHz, D $MSO-d_6$) $\delta ppm2.07(3H, s),$ 3. 85 (2H, s), 7. 71 (1H, s), 7. 73 (1H, t), 7.88 (1H, t), 8.17 (1H, dt), 8.29(1 H, t); MS (EI) m/z 313 (M⁺); 元素分析値C₁₄H₁₁N₅ S₂・1/4H₂ Oの計算値 (%) C, 52.89; H, 3.65; N, 2 2. 03, 測定値(%) C, 52.87; H, 3. 54; N, 21. 70. 【0125】 [実施例12] 5-(3-(2-(4-メトキシメチルー5ーメチルー2ーチアゾリル) エチニ ル) フェニル) -1H-テトラゾール: (工程1) 2-(4-メトキシベンジル)-5-(3 -(2-(4-メトキシメチル-2-チアゾリル)エチ ニル) フェニル) -2H-テトラゾールの合成 2-エチニル-4-メトキシメチルチアゾール659m g及び5-(3-イオドフェニル)-2-(4-メトキ シベンジル) -2H-テトラゾール1. 41gを実施例 1の工程4と同様に処理し、生成物を、シリカゲルを用 いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:酢酸エチル: n-ヘキサンークロロホルム=2:1) にて精製し、ク ロロホルム-n-ヘキサンから再結晶し、2-(4-メ トキシベンジル) -5-(3-(2-(4-メトキシメ チルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) ー2H-テトラゾール1. 487gを結晶性粉末として得た。 融点 105~107℃; NMR (400MHz, C DCl₃) δppm 3.49 (3H, s), 3. 80 (3H, s), 4.63 (2H, 5. 74 (2H, s), 6. $90\sim6$. 92 (2 H, m), 7.30 (1H, s), 7.39 \sim m), 7.49(1H, t), 7. 41 (2H, 7. 65 (1H, d), 8. 17 (1H, d), 8. 36 (1H, s); MS (EI) m/z 4 17 (M⁺) ; 元素分析値C₂₂H₁₉N₅ O₂ Sの計算 值(%) C, 63.29; H, 4.59; N, 1

6.77, 測定値(%) C,63.12; H,4.62; N,16.66.

【0126】(工程2) 5-(3-(2-(4-メト キシメチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1H-テトラゾールの合成

2- (4-メトキシベンジル) -5- (3- (2- (4-メトキシメチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2H-テトラゾール1.169gを実施例1の工程5と同様に処理し、粗結晶をエタノール-n-ヘキサンから再結晶し、表題物794mgを得た。

融点 $211\sim214$ °C; IR ν max cm⁻¹ 221 6; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ pp m 3.35 (3H, s), 4.54 (2H,

s), 7. 73 (1H, s), 7. 80 (1H, t), 7. 87 (1H, dt), 8. 17 (1H, dt), 8. 29 (1H, t); MS (EI) m/z 297 (M^+); 元素分析值 $C_{14}H_{11}$ N₅ OSの計算値 (%) C, 56. 55; H, 3. 73; N, 23. 55, 測定値 (%) C, 56. 52; H, 3. 84; N, 23. 66.

【0127】 [実施例13] 5-(3-(2-(4-メチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1H -テトラゾール:

(工程1) 5-(3-(2-(4-メチル-2-チア ゾリル) -2-オキソエチル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成 ジイソプロピルアミン1. 04gをTHF20mlに溶 解し、-78℃で撹拌下にn-ブチルリチウム(1.7) 1 Mのn - ヘキサン溶液) 5.6 m l を加え、0℃で1 0分間撹拌した。再び-78℃に冷却し、4-メチルチ アゾール1. 00gのTHF5ml溶液を加え、同温度 で0. 5時間撹拌した。反応液にメチル3-(2-(4) -メトキシベンジル) -5-テトラゾリル) フェニル酢 酸1. 45gのTHF溶液を加え、さらに同温度で1時 間撹拌した。反応液に水を加え室温まで戻し、1 N塩酸 を加えて酸性にした後、酢酸エチルで抽出した。抽出液 を、順次水、飽和食塩水出洗浄後、硫酸ナトリウムで乾 燥した。溶媒を留去し、残渣をシリカゲルを用いたカラ ムクロマトグラフィー (溶出液:酢酸エチル:n-ヘキ サン=1:3) にて精製し、エーテルーnーへキサンか ら再結晶し5-(3-(2-(4-メチル-2-チアゾ リル) -2-オキソエチル) フェニル) -2- (4-メ トキシベンジル) -2H-テトラソール0.60gを針 状晶として得た。

融点 $90 \sim 91$ °C; NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDC} 1_3)$ δppm 2. 52 (3H, s), 3. 79 (3H, s), 4. 51 (2H, s), 5. 72 (2H, s), 6. 89 (2H, d), 7. 3 7 (2H, d), 7. 40 \sim 7. 45 (3H, m), 8. 04 (1H, t), 8. 12 (1H, m)

s); 元素分析値C₂₁H₁₉N₅O₂Sの計算値 (%) C, 62.11; H, 4.92; N, 1 7.27, 測定値(%) C, 61.78; H, 4.78; N, 16.99.

【0128】(工程2) 5-(3-(2-(4-メチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成5-(3-(2-(4-メチル-2-チアゾリル)-2ーオキソエチル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例2の工程3と同様に処理し、生成物をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:酢酸エチル:n-ヘキサン=1:3)にて精製し、得られる結晶をエーテル-n-ヘキサンから再結晶して、5-(3-(2-(4-メチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール29mgを針状晶として得た。

融点 $95 \sim 96 \circ \circ$; NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDC} \ 1_3) \delta \text{ppm}$ 2. 50 (3 H, s), 3. 80 (3 H, s), 5. 74 (2 H, s), 6. 91 (2 H, d), 6. 95 (1 H, s), 7. 40 (2 H, d), 7. 48 (1 H, t), 7. 64 (1 H, d), 8. 16 (1 H, d), 8. 36 (1 H, s).

【0129】 (工程3) 5-(3-(2-(4-メチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-テトラゾールの合成

5- (3- (2- (4-メチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2 H-テトラゾール12.1mgを実施例1の工程5と同様に処理し、粗結晶をエタノールーエーテルから再結晶し、表題物6mgを得た。

融点 $224\sim227$ \mathbb{C} (decomp.); NMR $(400\text{MHz}, \text{DMSO-d}_6)\delta\text{ppm}2.43$ $(3\text{H}, s), 7.53(1\text{H}, s), 7.72(1\text{H}, t), 7.85(1\text{H}, d), 8.17(1\text{H}, d), 8.27(1\text{H}, s); M <math>\mathbb{C}$ \mathbb{C} \mathbb{C}

【 Q 1 3 0 】 [実施例 1 4] 5 - (3 - (2 - (4 - イソブチル-2 - チアゾリル) エチニル) フェニル) - 1 H - テトラゾール:

2-xチニルー4-4ソプチルチアゾール480mg及 び5 -(3-4オドフェニル) -2-(4-メトキシベ

ンジル) -2H-テトラゾール880mgを実施例1の工程4と同様に処理し、生成物をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:酢酸エチル:n-ヘキサン=1:4)にて精製し、クロロホルム-n-ヘキサンから再結晶し5-(3-(2-(4-イソプチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール867mgを終褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 0.9 5 (6H, d), 2.12 (1H, m), 2.67 (2H, d), 3.80 (3H, s), 5.74 (2H, s), 6.91 (2H, d), 6.94 (1H, s), 7.40 (2H, d), 7.48 (1H, t), 7.64 (1H, d), 8.15 (1H, d), 8.36 (1H, s).

【0131】(工程2) 5-(3-(2-(4-イソ プチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1H -テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-イソブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール970mgを実施例1の工程5と 同様に処理し、粗結晶をクロロホルム-n-ヘキサンか 5再結晶し、表題物360mgを得た。

融点 177~178℃; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm0. 90 (6H, d),
2.03 (1H, m), 2.63 (2H, d),
7.54 (1H, s), 7.73 (1H, t),
7.86 (1H, d), 8.16 (1H,
d), 8.32 (1H, s); MS (EI) m/
z 309 (M⁺); 元素分析値C₁₆H₁₅N₅ S·1
/4H₂ Oの計算値 (%) C, 61.22; H,
4.98; N, 22.31, 測定値 (%) C, 6
0.90; H, 4.86; N, 21.97.

【0132】 [実施例15] 5-(3-(2-(4-エチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1H -テトラゾール:

(工程1) 5-(3-(2-(4-エチルー2-チア ゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベ ンジル) -2H-テトラゾールの合成

4-エチルー2-エチニルーチアゾール460mg及び5-(3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール1.0gを実施例1の工程4と同様に処理し、生成物をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:酢酸エチル:n-ヘキサン=1:3)にて精製し、エタノールーn-ヘキサンから再結晶し5-(3-(2-(4-エチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール730mgを淡黄色針状晶として得た。

融点 116~117℃; NMR (400MHz, C DCl_3) δppm 1. 34 (3H, t), 2. 85 (2H, q), 3.80 (3H, s), 6. 90 (2H, d), 6. 96 (1H, s), 7. 39 (2H, d), 7. 48 (1H, t), 7. 66 (1H, d), 8. 15 (1H, d), 8.36(1H, s); 元素分析值C₂₂H₁₉ N₅ OS・1/2H₂ Oの計算値(%) C, 64.3 7; H, 4. 91; N, 17. 06, 測定値 (%) C, 64. 62; H, 4. 78; N, 1 6. 73. 【0133】(工程2) 5-(3-(2-(4-エチ ルー2-チアソリル) エチニル) フェニル) -1H-テ トラゾールの合成 5- (3-(2-(4-エチル-2-チアゾリル) エチ ニル)フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2 H-テトラゾール736mgを実施例1の工程5と同様 に処理し、粗結晶をエタノールーエーテルから再結晶 し、表題物268mgを淡黄色結晶性粉末として得た。

し、表題物 268 m g を淡黄色結晶性粉末として得た。 融点 $198\sim200$ C; NMR (400 MHz, D MSO- d_6) δ p p m 1. 26(3H, t), 2. 78(2H, q), 7.54(1H, s), 7. 73(1H, t), 7. 86(1H, d), 8. 16(1H, d), 8. 29(1H, s); 元素分析値 $C_{14}H_{11}N_5$ Sの計算値(%) C, 59.77; H, 3.94; N, 24.89, 測定値(%) C, 59.30; H, 4.07; N, 24.71.

【0134】 [実施例16] 5-(3-(2-(4-n-オクチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 2-(4-x)キシベンジル) -5-(3 -(2-(4-n-x) -(2-(4-n-

融点 $47\sim48\%$; NMR $(400\text{MHz}, \text{CDC} \ 1_3)$ δ ppm 0.88 (3H, t), 1.27 \sim 1.75 (12H, m), 2.80 (2H, t), 3.79 (3H, s), 5.55 (2H, s), 6.89 \sim 6.92 (2H, m), 6.94 (1H, s), 7.38 \sim 7.41 (2H, m)

m), 7.47 (1H, t), 7.64 (1H, d), 8.15 (1H, d), 8.36 (1H, s); MS (EI) m/z 485 (M^+); 元素分析値 $C_{28}H_{31}N_5$ OSの計算値 (%) C, 69.24; H, 6.43; N, 14.42, 測定値 (%) C, 68.98; H, 6.32; N, 14.35.

【0135】(工程2) 5-(3-(2-(4-n-オクチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1 H-テトラゾールの合成

融点 $104\sim105$ ℃; NMR $(400\text{MHz}, D\text{MSO}-d_6)$ δ ppm0. 86 (3H, t), $1.25\sim1.68$ (12H, m), 2.74 (2H, t), 7.53 (1H, s), 7.72 (1H, t), 7.86 (1H, d), 8.16 (1H, d), 8.28 (1H, s); MS (EI) m/z 365 (M+);元素分析値 C_{20} H₂₃ N₅ Sの計算値 (%) C, 65.72; H, 6.34; N, 19.17, 測定値 (%) C, 65.69; H, 6.27; N, 19.24.

【0136】 [実施例17] 5-(4-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-チエ ニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(4-ブロモ-2-チエニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成5-(4-ブロモ-2-チエニル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(4-ブロモ-2-チエニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 70~72℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーnーヘキサン); IRνmax cm⁻¹; 3108,3004,2964,2836,1682,1614,1588,1574,1516; NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 3.80(3H, s), 5.70(2H, s), 6.88~6.91(2H, m), 7.31(1H, d), 7.35~7.38(2H, m), 7.67(1H, d); MS(EI) m/z 352[(M⁺+2)+1],350[(M⁺)+1]; 元素分析値C₁₃H₁₁BrN₄OSの計算値(%) C,44.46; H,3.16; N,15.95, 測定値(%) C,44.54; H,3.11; N,15.99.

【0137】(工程2) 5-(4-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-チエニ

ル) -1H-テトラゾールの合成

5- (4-プロモー2-チエニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、引き続き実施例1の工程5と同様に脱4-メトキシベンジル化反応を行い、表題物を得た。

融点 224~230℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); IRνmax cm⁻¹; 3088, 2 216, 1580, 1518; NMR (400MH z, DMSO-d₆) δppm 1.84~2.31 (6H, m), 3.63~3.71 (1H,

m), 7.54 (1H, s), 7.93 (1H, s), 8.40 (1H, s); MS (FAB) m/z 314 (M^+ +1); 元素分析値 $C_{14}H_{11}$ N₅ S₂ の計算値 (%) C, 52.15; H, 3.75; N, 21.72, 測定値 (%) C, 52.15; H, 3.67; N, 21.91.

【0138】 [実施例18] 5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-チエ ニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(5-プロモ-2-チェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成 <math>5-(5-プロモ-2-チェニル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、<math>5-(5-プロモ-2-チェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 87~89℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーnーへキサン); IRνmax cm⁻¹; 3000, 284 0, 1614, 1580, 1520; NMR (400 MHz, CDCl₃) δppm 3. 79 (3H, s), 5. 69 (2H, s), 6. 88~6. 9

1 (2H, m), 7.07 (1H, d), $7.37 \sim 7.35 (2H, m)$, 7.51 (1H, d); $MS (EI) m/z 352 [(M^+ + 2) + 1]$, $350 [(M^+) + 1]$; 元素分析値 $C_{13}H_{11}$ $BrN_4 OSの計算値(%) C, 44.46; H, <math>3.16$; N, 15.95, 測定値(%) C, 44.65; H, 3.11; N, 15.94.

【0139】(工程2) 5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-1H-テトラゾールの合成

5-(5-プロモ-2-チエニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチルー2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、引き続き実施例1の工程5と同様に脱4-メトキシベンジル化反応を行い、表題物を得た。

融点 252~257℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); IRνmax cm⁻¹; 2976, 22 00, 1566, 1510; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.84~2.34 (6 H, m), 3.62~3.71(1H, m), 7.44(1H, d), 7.52(1H, s), 7.55(1H, d); MS(FAB) m/z 314(M^++1); 元素分析値 $C_{14}H_{11}N_5S_2$ ・1/2 H_2 Oの計算値(%) C, 52.15; H, 3.75; N, 21.72, 測定値(%) C, 52.15; E, M_2 15; H, 3.67; N, 21.91. 【0140】 [実施例19】 M_2 5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-フリル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(5-プロモ-2-フリル)-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール及び5-(5-プロモ-2-フリル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(5-プロモー2-フリル)-1H-テトラゾール を実施例1の工程3と同様に処理し、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーで2種の異性体を分離し、 <math>5-(5-プロモー2-チエニル)-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾールの機器データは以下のとおりである。

融点 $70\sim71$ °C $(n-\sim$ キサンにて結晶化); N MR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 3. 79 (3H, s), 5. 72 (2H, s), 6. 46 (1H, d), 6. 87 \sim 6. 91 (2H, m), 7. 05 (1H, d), 7. 36 \sim 7. 38 (2H, m); MS (EI) m/z 337 $[(M^++2)+1]$, 335 $[(M^+)+1)$; 元素分析値C₁₃H₁₁BrN₄O₂の計算値(%) C, 46. 58; H, 3. 31; N, 16. 72, 測定値(%) C, 46. 66; H, 3. 33; N, 16. 89. 及び、5-(5-プロモー2-チエニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2+0 + フェールの機器データは以下のとおりである。

融点 $113\sim114$ [°] (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\wedge$ キサン); NMR (400MHz, CDC1 $_3$) δ p p m 3. 78 (3 H, s), 5. 76 (2 H, s), 6. 55 (1 H, d), 6. $84\sim6$. 88 (2 H, m), 7. 18 (1 H, d), 7. $27\sim7$. 31 (2 H, m); MS (E I) m/z 337 [(M^+ +2) +1), 335 [(M^+) + 1]; 元素分析値 $C_{13}H_{11}$ Br N_4 O_2 の計算値(%) C, 46. 58; H, 3. 31; N, 16. 72, 測定値(%) C, 46. 69; H, 3. 33; N, 16. 93.

【0141】 (工程2) 5-(5-イオド-2-フリル)-1-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5- (5-ブロモ-2-チエニル) -1- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール833mg、ヨウ化カリウム3.98g及びヨウ化第一銅2.29gをDM

F20ml中、窒素気流下に加熱還流した。冷却後、反応液を水200mlに注ぎ、析出結晶をろ取した。析出結晶をクロロホルムに懸濁し、硫酸マグネシウムで脱水後、溶媒を留去した。残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:クロロホルム:nーヘキサン=1:1)にて精製し、5ー(5ーイオドー2ーフリル)-1ー(4ーメトキシベンジル)-2Hーテトラゾール88mgを淡黄色結晶性粉末として得た。

融点 $103\sim105$ [°]C $(n-\wedge$ キサンにて結晶化); NMR $(400MHz, CDCl_3)$ δ ppm 3.79 (3H, s), 5.72 (2H, s), 6.69 (1H, d), 6.87 \sim 6.91 (2H, m), 7.00 (1H, d), 7.36 \sim 7.38 (2H, m).

【0142】(工程3) 5-(5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-1H-テトラゾールの合成

5- (5- (2- (4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) -2-フリル) -1- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールと4-シクロプチルー2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、5- (5- (2- (4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) -2-フリル) -1- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを淡黄色結晶性粉末として得た。

融点 $10.7 \sim 10.8$ °C; NMR (40.0MHz, CD Cl₃) δ ppm 1.88 \sim 2.10(2H, m), 2.26 \sim 2.41(4H, m), 3.64 \sim 3.73(1H, m), 3.80(3H, s), 5.74(2H, s), 6.89(1H, d), 6.89 \sim 6.92(2H, m), 6.99(1H, s), 7.14(1H, d), 7.37 \sim 7.41(2H, m).

【0143】(工程4) 5-(5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-フリル) -1H-テトラゾールの合成

5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-フリル) -1-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $164\sim166$ C (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\Lambda$ キサン); NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ p p m 1.86 \sim 2.34 (6H, m), 3.64 \sim 3.73 (1H, m), 7.41 (1H, d), 7.43 (1H, d), 7.64 (1H, s); MS (FAB) m/z298 (M⁺+1); 元素分析値 $C_{14}H_{11}N_5$ OSの計算値 (%) C,56.55; H,3.73; N,23.56, 測定値 (%) C,56.22; H,3.81; N,23.86.

【0144】 [実施例20] 5-(5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -3-ピリジル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 3ープロモー5ー(2ー(4ーメトキシベンジル)ー2Hーテトラゾールー5ーイル) ピリジンの合成

3-ブロモー5- (1H-5-テトラゾリル) ピリジン を実施例1の工程3と同様に処理し、3-ブロモー5- (2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールー5-イル) ピリジンを得た。

融点 $113\sim115$ [°] (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 $_3$) δ p p m 3.80 (3 H, s), 5.76 (2 H, s), 6.90 \sim 6.93 (2 H, m), 7.38 \sim 7.40 (2 H, m), 8.5 (1 H, t), 8.75 (1 H, d), 9.2 6 (1 H, d); 元素分析値 $C_{14}H_{12}$ Br N_5 Oの計算値 (%) C_{14} C, 48.57; H, 3.49; N,

20.23, 測定値(%) C, 48.48; H, 3.40; N, 20.30. 【0145】(工程2) 3ーイオドー5ー(2-(4

ーメトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ピリジンの合成

5-(5-プロモー2-チェニル)-1-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例19と同様に処理し、<math>3-イオド-5-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ピリジンを得た。

融点 123~125℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 3) δppm 3.81 (3H, s), 5.76 (2H, s), 6.90~6.93 (2H, m), 7.39~7.41 (2H, m), 8.7 4 (1H, t), 8.80 (1H, d), 9.2 8 (1H, d).

【0146】(工程3) 5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-3-ピリジル)-1H-テトラゾールの合成

3ーイオドー5ー(2ー(4ーメトキシベンジル)-2 Hーテトラゾールー5ーイル)ピリジンと4ーシクロブ チルー2ーエチニルチアゾールと実施例1の工程4と同様に処理し、引き続き実施例1の工程5と同様に処理して、表題物を得た。

融点 113~115℃ (再結晶溶媒:クロロホルム); NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.87~2.33 (6H, m), 3.65~3.73 (1H, m), 7.57 ((1H, s), 8.43 (1H, t), 8.73 (1H, d), 9.20 (1H, d); MS (FAB) m/z 309 (M⁺ +1);元素分析値C₁₅H₁₂N₆

Sの計算値 (%) C, 58. 43; H, 3. 92; N, 27. 25, 測定値 (%) C, 58. 44; H, 3. 68; N, 27. 25.

【0147】 [実施例21] 5-(6-(2-(4-シ クロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-ピリジ ル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 6-プロモー2-(1-(4-メトキシベ ンジル) -1H-テトラゾール-5-イル) ピリジン、 及び 6-プロモー2-(2-(4-メトキシベンジ ル) -2H-テトラゾール-5-イル) ピリジンの合成 6-プロモー2-(1H-5-テトラゾリル) ピリジン を実施例1の工程3と同様に処理し、6ープロモー2ー (1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール -5-イル) ピリジン、及び 6-プロモー2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) ピリジンを、約2:3の混合物として得た。 NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 3.7$ 6 and 3.79 (3H, each s), 5.79 and 6.10 (2H, eachs), 6.83 and 6.89 (2H, d), 7. 40 and 7.44 (2H, each d), 7. $57 \sim 7$. 75 (2H, m), 8. 17 an d 8.30(1, d).

【0148】(工程2) 6-イオド-2-(1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール-5-イル) ピリジン、及び 6-イオド-2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) ピリジンの合成

上記、ブロモ体を、実施例19の工程2と同様に処理し、6-イオド-2-(1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール-5-イル)ピリジン、及び 6-イオド-2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ピリジンを、約3:2の混合物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p pm 3.7 6 and 3.79 (3H, each s), 5.79 and 6.09 (2H, each s), 6.83 and 6.89 (2H, each d), 7.39 and 7.44 (2H, each d), 7.38~7.52 (1H, m), 7.78~7.86 (1H, m), 8.17 and 8.30 (1H, d).

【0149】(工程3) 5-(6-(2-(4-)2-(4

ル) エチニル) -2-ピリジル) -1- (4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾール、及び 5- (6- (2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-ピリジル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを、1位:2位≒3:2の混合物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.8 $8\sim2.10$ (2H, m), 2.27 ~2.45 (4 H, m), 3.70 (1H, m), 3.75 and 3.79 (3H, each s), 5.8 1 and 6.15 (2H, each s), 6.82 and 6.89 (2H, each d), 7.02 and 7.08 (1H, eac h s), 7.41 and 7.49 (2H, e ach d), 7. $6.8 \sim 7.72$ (1H, m), 7. $84 \sim 7$. 92 (1H, m), 8.22 and 8.32(1H, each d); 元素分析 値C₂₃H₂₀N₆ OSの計算値(%) C, 64.47; H, 4.70; N, 19.61, 測定値(%) C, 64. 36; H, 4. 76; N, 19. 78. 【0150】(工程4) 5-(5-(2-(4-シク ロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー2ーピリジ ル) -1H-テトラゾールの合成

上記、工程3の化合物を、実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 162~168℃ (再結晶溶媒: エーテルーnーヘキサン); NMR (400MHz, DMSO-d 6) δppm 1.88~2.13 (2H, m), 2.34~2.42 (4H, m), 3.72 (1H, m), 7.60 (1H, s), 7.68 (1H, d), 7.94 (1H, t), 8.10 (1H, d).

【0151】 [実施例22] 5-(6-(2-(4-5)) 5-(6-(2-(4-5)) -2-(4-5)

(工程1) 6-アセトキシー2-(1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール-5-イル)ベンゾチアゾールの合成

6-アセトキシー2-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンゾチアゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、6-アセトキシー2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンゾチアゾールを得た。

融点 $144 \sim 148$ °C (結晶性粉末); IR ν max c m⁻¹ 1754; NMR (400MHz, CDC l 3) δ p p m 2. 36 (3H, s), 3. 80 (3H, s), 5. 80 (2H, s), 6. 9 1 (2H, d), 7. 28 (2H, d), 7. 4 4 (1H, d), 7. 74 (1H, d), 8. 1 9 (1H, d); MS (FAB) m/z 382

(M⁺ + 1) ;元秦分析值C₁₈H₁₅N₅ O₃ Sの計算值 (%) C, 56.68; H, 3.96; N, 1 8.36, 測定値(%) C, 56.73; H, 4.04; N, 18.55.

【0152】(工程2) 6-ヒドロキシ-2-(1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール-5-イル) ベンゾチアゾールの合成

6ーアセトキシー2ー(1ー(4ーメトキシベンジル) ー1Hーテトラゾールー5ーイル)ベンゾチアゾール6 68mgをTHF20mlに溶解し、0.25N水酸化 ナトリウム水溶液10mlを加え、室温で4時間撹拌した。反応液を0.2N塩酸300mlに注ぎ、析出した 結晶をろ取、水洗後、乾燥し、6ーヒドロキシー2ー (1ー(4ーメトキシベンジル)ー1Hーテトラゾール ー5ーイル)ベンゾチアゾール594mgを黄色粉末と して得た。

融点 177~180℃ (結晶性粉末); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 3.75 (3H, s), 5.98 (2H, s), 6.98 (2H, d), 7.07 (2H, dd), 7.44 (2H, d), 7.50 (1H, d), 7.96 (1H, d), 10.13 (1H, s); MS (FAB) m/z 340 (M⁺+1); 元素分析値C₁₆H₁₃N₅O₂ Sの計算値 (%) C, 56.63; H, 3.86; N, 20.64, 測定値 (%) C, 56.26; H, 3.98; N, 20.31.

【0153】(工程3) 2-(1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール-5-イル)ベンゾチアゾール-5-イル)トリフルオロメタンスルフォネートの合成

6ーヒドロキシー2ー(1ー(4ーメトキシベンジル) ー1Hーテトラゾールー5ーイル)ベンゾチアゾール5 94mg及びエチルジイソプロピルアミン1m1を塩化 メチレン10m1に溶解し、-78℃で撹拌下にトリフ ルオロメタンスフォン酸無水物0.44m1を加えた。 反応液をさらに室温で15時間撹拌後、0.2N塩酸2 50m1に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。抽出液を1N 塩酸、飽和食塩水出洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し た。溶媒を留去して得られた残渣をシリカゲルを用いた カラムクロマトグラフィー(溶出液:nーヘキサン一酢 酸エチル=5:1)にて精製し、2ー(1ー(4ーメト キシベンジル)-1Hーテトラゾールー5ーイル)ベン ゾチアゾールー5ーイル)トリフルオロメタンスルフォ ネート546mgを粉末として得た。

融点 $115\sim116$ °C; NMR (400MHz, C) DCl₃) δ ppm3. 80 (3H, s), 5. 8 5 (2H, s), 6. 91 (2H, d), 7. 4 7 (1H, dd), 7. 93 (1H, d), 8. 27 (1H, d);

MS (FAB) m/z 472 (M^++1); 元素分析值 $C_{17}H_{12}F_3$ N_5 O_4 S_2 の計算値(%) C, 43.31; H, 2.57; N, 14.86, 測定値(%) C, 43.58; H, 2.68; N, 15.11.

【0154】(工程4) 5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンゾチアゾール-5-イル)-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾールの合成

2- (1- (4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾ ールー5ーイル) ベンプチアゾールー5ーイル) トリフ ルオロメタンスルフォネート471mg、ヨウ化第一銅 19mg、及びピス(トリフェニルフォスフィン)パラ ジウム [2] ジクロリド35mgにトリエチルアミン 0. 2m1及びDMF5m1を加え、窒素気流下、室温 で1時間撹拌した。反応液に4-シクロブチルー2-エ チニルチアソール245mgを加え、90℃で4時間撹 拌した。冷却後、反応液を1N塩酸250mlに注ぎ、 酢酸エチルで抽出した。抽出液を、飽和食塩水で洗浄 後、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去して得ら れた残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィ ー (溶出液:n-ヘキサンー酢酸エチル=4:1) にて 精製し、5-(6-(2-(4-シクロブチルー2-チ アソリル) エチニル) ベンソチアソールー5ーイル) -1- (4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾール3 08mgを針状晶として得た。

融点 161°C; NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 1. 91~2. 12 (2H, m), 2. 28~2. 43 (4H, m), 3. 71 (1H, m), 3. 80 (3H, s), 5. 83 (2H, s), 6. 91 (2H, d), 6. 9 9 (1H, s), 7. 45 (2H, d), 7. 74 (1H, dd), 8. 19 (1H, d), 8. 21 (1H, d).

【0155】(工程5) 5-(6-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2ーベンゾチアゾリル)-1H-テトラゾールの合成5-(6-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンゾチアゾール-5-イル)-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を黄色粉末として得た。

融点 225~227℃ (再結晶溶媒:クロロホルム); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.90~2.04(2H, m), 2.22~2.32(4H, m), 3.69(1H, m), 7.57(1H, s), 7.89(1H, d), 8.25(1H, d), 8.65(1H, s); MS (FAB) m/z365(M⁺+1); 元素分析値C₁₇H₁₂N₆S₂の計算値(%) C,5

6.03; H,3.32; N,23.06, 測定値(%) C,55.79; H,3.35; N,23.06.

【0156】 [実施例23] 5-(5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-ベン ゾオキサゾリル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(2-(4-シクロブチルー2-チア ゾリル) エチニル) -2-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンゾオキサゾールの合成 <math>5-イオド-2-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンゾオキサゾールを実施例<math>1の工程4と同様に処理し、5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンゾオキサゾールを得た。

【0157】(工程2) 5-(5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-ベンゾオキサゾリル)-1H-テトラゾールの合成5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンゾオキサゾールを、実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を微細針状晶として得た。

融点 $226\sim229$ C (decomp.); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.84 \sim 2.06 (2H, m), 2.20 \sim 2.34 (4H, m), 3.68 (1H, m), 7.54 (1H, s), 7.84 (1H, dd), 8.04 (1H, d), 8.29 (1H, d); MS (FAB) m/z 349 (M⁺ +1); 元素分析値C₁₇H₁₂N₆ OSの計算値 (%) C, 57.13; H, 3.67; N, 23.52, 測定値 (%) C, 57.55; H, 3.54; N, 23.33. 【0158】 [実施例24] 7-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -3-(1H-テトラゾール-5-イル) -4H-ピリド [1, 2-a] ピリミジン-3-オン:

(工程1) 7ープロモー3ー(2-(4ーメトキシベンジル)-2Hーテトラゾール-5ーイル)-4Hーピリド[1,2-a]ピリミジン-3ーオンの合成2ーアミノ-5ープロモピリジン3.57g及びエチル3ージメチルアミノ-2-(2-(4-(メトキシベ

ンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) アクリル酸7.94gをプロピオン酸30ml中、3日間加熱還流した。反応液を水300mlに注ぎ、析出した結晶をろ取、水洗後、乾燥した。これをシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:クロロホルム:メタノール=200:1)にて精製し、7-プロモー3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-4H-ピリド[1,2-a]ピリミジン-3-オン4.03gを結晶性粉末して得た。

融点 $172\sim175$ °C; $IRvmax cm^{-1} 170$ 6; $NMR (400MHz, CDCl_3) \delta ppm$ 3. 79 (3H, s), 5.82 (2H, s),6. $88\sim6.91 (2H, m), 7.41\sim7.43 (2H, m), 7.67 (1H, d), 7.90 (1H, dd), 9.22 (1H, s),$ 9. $38 (1H, d); MS (EI) m/z 414 [(M⁺ + 2) +1)], 412 [(M⁺) + 1)]; 元素分析値<math>C_{17}H_{13}BrN_6O_2$ の計算値(%) C,49.41; H,3.17; N,20.34, 測定値(%) <math>C,49.24; H,3.24; N,20.39.

【0159】(工程2) 7-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-3-(1H-テトラゾール-5-イル)-4H-ピリド[1, 2-a]ピリミジン-3-オンの合成

7ーブロモー3ー(2ー(4ーメトキシベンジル)ー2 Hーテトラゾールー5ーイル)ー4Hーピリド[1,2 ーa]ピリミジンー3ーオン413mg、4ーシクロブ チルー2ーエチニルチアゾール163mg、酢酸パラジ ウム[2]22mg、及びトリフェニルフォスフィン5 2mgをトリエチルアミン20ml中、4時間加熱還流 した。反応液を濃縮し、クロロホルム50mlを加えて 順次、1N塩酸、水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、 飽和食塩水で洗浄した後、硫酸ナトリウムで乾燥した。 溶媒を留去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶出液:クロロホルム:メタノール=2 00:1)にて精製した後、得られたカップリング成績 物をこれ以上精製することなく、実施例1の工程5と同様に処理し、表題物105mgを淡黄色結晶性粉末して 得た。

融点 >300℃ (再結晶溶媒:クロロホルム-n-ヘキサン); IRνmaxcm⁻¹ 1706; NMR (400Mz, DMSO-d₆) δppm 1.84~2.32(6H, m), 3.65~3.73(1H, m), 7.61(1H, s), 7.80(1H, d), 8.09(1H, d), 8.94(1H, br s), 9.34(1H, s); MS(FAB) m/z 376(M⁺ +1); 元素分析値C₁₈H₁₃N₇OSの計算値(%) C, 57.59; H, 3.49; N, 26.12, 測定値

(%) C, 57. 95; H, 3. 40; N, 2 5. 93.

【0160】 [実施例25] 5-(5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-ベン ゾ[b] チエニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(5-プロモー2-ベンゾ [b] チエ ニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラ ゾールの合成

5-(5-プロモ-2-ベンゾ [b] チエニル) -1H -テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(5-プロモ-2-ベンゾ [b] チエニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを得た。

融点 $140\sim142$ [°]C (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\wedge$ キサン); IR ν max c m⁻¹ 3080, 2840, 1614, 1584, 1538, 1516; NMR (400Mz, CDCl₃) δ ppm 3.81 (3H, s), 5.75 (2H, s), 6.90 \sim 6.93 (2H, m), 7.39 \sim 7.41 (2H, m), 7.48 (1H, dd), 7.73 (1H, d); MS (EI) m/z 402 [(M+2)+1], 402 [(M+2)+1]; 元素分析値C₁₇H₁₃BrN₄OSの計算値(%) C, 50.88; H, 3.27; N, 13.96, 測定値(%) C, 50.57; H, 3.27; N, 13.91.

【0161】(工程2) 5-(5-イオド-2-ベン ゾ[b] チエニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(5-プロモー2-ベンゾ [b] チエニル) -1H ーテトラゾールを実施例 19の工程 2 と同様に処理し、 5-(5-イオド-2-ベンゾ [b] チエニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを得た。

融点 $131\sim134$ [°]C (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400Mz, CDCl $_3$) δ ppm $3.80(3H, s), <math>5.75(2H, s), 6.90\sim6.92(2H, m), 7.39\sim7.41(2H, m), 7.66\sim7.60(2H, m), 7.94(1H, s), 8.19(1H, s).$

【0162】(工程3) 5-(5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-ベンゾ[b]チエニル)-1H-テトラゾールの合成5-(5-イオド-2-ベンゾ[b]チエニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロプチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、得られたカップリング成績物をこれ以上精製することなく、実施例1の工程5と脱4-メ

トキシベンジル化を行い、表題物を得た。

融点 241~244°C (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノール); IRνmax cm⁻¹ 2208, 1584, 1532, 1504; NMR (400Mz, DMSO-d₆) δppm 1.85~2.34 (6H, m), 3.64~3.73 (1H, m), 7.54 (1H, s), 7.71 (1H, dd), 8.20 (1H, s), 8.24 (1H, d), 8.41 (1H, s); MS (FAB) m/z 364 (M⁺ +1); 元素分析値C₁₈H₁₃N₅S₂の計算値(%) C,59.48; H,3.60; N,19.27, 測定値(%) C,59.21; H,3.70; N,19.31.

【0163】 [実施例26] 5-(6-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-オキソ-2H-ベンゾピラン-3-イル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(5-プロモ-2-オキソ-2H-ベンソピラン-3-イル)-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール、及び <math>5-(5-プロモ-2-オキソ-2H-ベンゾピラン-3-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成 <math>5-(5-プロモ-2-オキソ-2H-ベンゾピラン-3-イル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、<math>5-(5-プロモ-2-オキソ-2H-ベンゾピラン-3-イル)-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール、及び <math>5-(5-プロモ-2-オキソ-2H-ベンゾピラン-3-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-デトラゾールを1位: <math>2位=1:1 の混合物として得た。

 $IRv \max cm^{-1}$ 2840, 1750, 1722, 1 614, 1606, 1568, 1516; NMR (4 0.0Mz, CDCl₃) δ ppm 3.68 and 3.80 (3H, each s), 5.76 (1 H, s), 5.81 (1H, s), 6.71 \sim 6. 74 (1H, m), 6. $89 \sim 6$. 92 (1 H, m), 7.06 \sim 7.08(1H, m), 7. 29 and 7. 31 (1H, each d), 7. $40 \sim 7$. 42 (1H, m), 7. 65, 7. 70, 7. 75 and 7. 76 (2H, each m), 7. 99 (1/2H, s), 8. 58 (1/2H, s); MS (FAB) m/z 414 $[(M^+ + 2) + 1], 412[(M^+) + 1];$ $\bar{\pi}$ 素分析値C₁₈H₁₃N₄ BrO₃ の計算値(%)C, 5 2. 32; H, 3. 17; N, 13. 56, 測定 值(%) C, 51. 93; H, 3. 24; N, 1 3. 38.

【0164】(工程2) 5-(6-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-オキソー2H-ベンプピラン-3-イル)-1H-テトラゾール

の合成

上記、プロモ体と4-シクロプチルー2-エチニルチア ソールを実施例1の工程4と同様に処理し、得られたカ ップリング成績物をこれ以上精製することなく、実施例 1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 >300℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーnーへキサン); IR ν max c m⁻¹ 2980, 2944, 2216, 1742, 1708, 1622, 1606, 1578, 1504; NMR (400Mz, CDC13) δppm 1.87~2.33 (6H, m), 3.63~3.72 (1H, m), 7.51 (1H, d), 7.54 (1H, s), 7.85 (1H, dd), 8.20 (1H, d), 8.53 (1H, s); MS (FAB) m/z 376 (M⁺ +1); 元素分析値C₁₉H₁₃N₅ O₂ の計算値 (%) C, 60.79; H, 3.49; N, 18.66, 測定値 (%) C, 60.47; H, 3.52; N, 18.61.

【0165】 [実施例27] 5-(5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-ベンソ [b] フリル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(5-プロモー2-ベンゾ [b] フリル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(5-プロモ-2-ベンソ [b] フリル) -1 H- テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、 $5-\cdot(5-プロモ-2-ベンソ [b] フリル) -2-(4-メトキシベンジル) -2 H-テトラゾールを得た。$

融点 143~145℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーエーテル); NMR (400Mz, CDCl₃) δ p p m 3.79 (3H, s), 5.78 (2H, s), 6.90 (2H, d), 7.41 (2H, d), 7.43 (1H s), 7.47 (1H,

s), 7.79 (1H, s). 【0166】 (工程2) 5-(5-イオド-2-ベン

【0166】 (工程2) 5- (5-4カト-2-ペン ゾ[b] フリル) -2- (4-メトキシベンジル) -2 H-テトラゾールの合成

5- (5-プロモー2-ベンゾ [b] フリル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール実施例 19の工程2と同様に処理し、5- (5-イオド-2-ベンゾ [b] フリル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを得た。

融点 136~138℃ (再結晶溶媒:エーテルーへキサン); NMR (400Mz, CDC1₃) δppm 3.80(3H, s), 5.78(2H, s), 6.90(2H, d), 7.37(1H,

d), 7.41 (1H s), 7.41 (1H, d), 7.63 (1H, dd), 8.00 (1H, d).

【0167】(工程3) 5-(5-(2-(4-シク

ロプチルー2ーチアソリル) エチニル) -2-ベンソ [b] フリル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H -テトラゾールの合成 5- (5-イオド-2-ベンソ [b] フリル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールと4-シクロプチルー2-エチニルチアゾールを実施例1の工 程4と同様に処理し、、5-(5-(2-(4-シクロ ブチルー2ーチアゾリル) エチニル) -2ーベンゾ [b] フリル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H -テトラゾールを得た。 融点 154~155℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー エーテル); NMR (400Mz, CDCl₃) δ p $pm 1.89 \sim 2.11 (2H, m), 2.28$ ~ 2.43 (4H, m), 3.70 (1H, m). 3.80 (3H, s), 5.79 (2H, s), 6.91 (2H, d), 6.95 (1 H, s), 7.42 (2H, d), 7.49 (1H, s), 7.60 (2H, s), 7.92 (1H, s). 【0168】(工程4) 5-(5-(2-(4-シク ロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) -2ーベンゾ [b] フリル) -1H-テトラゾールの合成 5-(5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリ ル) エチニル) -2-ベンゾ [b] フリル) -2- (4 -メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例1 の工程5と同様に処理し、表題物を得た。 融点 207~212℃ (再結晶溶媒:エタノールーク ロロホルム-n - \wedge キサン) : IR ν max c m⁻¹ 2 216; NMR $(400Mz, DMSO-d_6) \delta p$ pm 1.85~2.06 (2H, m), 2.19 ~ 2.52 (4H, m), 3.68 (1H, m). 7.53 (1H, s), 7.74 (1H, d), 7.77 (1H, s), 7.88 (1 H, d), 8.16(1H, s); 元素分析值 C₁₈H₁₃N₅ OSの計算値(%)C, 62.23; H, 3. 77; N, 20. 16, 測定値(%) C, 61. 95; H, 3. 96; N, 20. 10. 【0169】 [実施例28] 5-(7-(2-(4-シクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) -4-オキ ソー4 Hーベンソピラン-2-イル) カルボン酸: (工程1) エチル 5-(4-オキソー7-トリフル オロメタンスルフォニルオキシー4 Hーベンプピランー 2-イル) カルボキシレートの合成 エチル 5- (7-ヒドロキシ-4-オキソー4H-ベ ンゾピラン-2-イル) カルボキシレートを実施例22 の工程3と同様に処理し、エチル 5-(4-オキソー 7-トリフルオロメタンスルフォニルオキシ-4H-ベ ンゾピラン-2-イル) カルボキシレートを得た。 融点 125~127℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー

 $n-\Delta + \psi$); IR $v \max c m^{-1}$ 2216; NM

R $(400Mz, CDCl_3) \delta ppm 1.45 (3)$ H, t), 4.48(2H, q), 7.15 (1H, s), 7.37 (1H, dd), 7.5 9 (1H, d), 8.31 (1H, d). 【0170】(工程2) エチル 5-(7-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -4 ーオキソー4 Hーベンソピランー2 ーイル) カルボキシ レートの合成 エチル 5-(4-オキソー7-トリフルオロメタンス ルフォニルオキシー4 Hーベンソピランー2 ーイル) カ ルボキシレートと4-シクロブチルー2-エチニルチア ゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、エチル 5 - (7-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -4-オキソー4H-ベンゾピラン-2-イ ル)カルボキシレートを得た。 融点 138~141℃ (再結晶溶媒:エーテルーn-ヘキサン); NMR (400Mz, CDCl₃) δ p pm 1. 44 (3H, t), 1. 91~2. 43 (6 H, m), 3. $68 \sim 3$. 76 (1 H,m), 4.47 (2H, q), 7.04 (1H, s), 7.13 (1H, s), 7.61 (1 H, dd), 7.82(1H, d), 8.18 (1H, d). 【0171】(工程3) 5-(7-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー4ーオキソー 4 Hーベンゾピランー 2 ーイル) カルボン酸の合成 5-(7-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリ ル) エチニル) -4-オキソ-4H-ベンゾピラン-2 ーイル)カルボキシレート228mg及び炭酸水素ナト リウム230mgにエタノール10ml及び水1mlを 加え、2時間加熱還流した。冷却後、反応液に水100 mlを加え、1N塩酸を加えてpH3に調整した。析出 した結晶をろ取、水洗後、乾燥した。得られた粗結晶を クロロホルムーn-ヘキサンから再結晶し、表題物17 5mgを結晶性粉末として得た。 融点 240~243℃(decomp.); IRv $max cm^{-1} 2216, 1734, 1654; NMR$ $(400 Mz, DMSO-d_6) \delta ppm 1.87 \sim$ 2. 32 (6H, m), 3. $65\sim3$. 73 (1 H, m), 6.96(1H, s), 7.62 (1H, s), 7.76 (1H, d), 8.08 s), 8.09(1H, d); MS (1 H, (FAB) m/z 352 (M⁺ +1); 元素分析 値C₁₉H₁₃NO₄ S・1/4H₂ Oの計算値(%)C,

64.12; H, 3.82; N, 3.94, 測定値(%) C, 64.29; H, 3.83; N, 3.81.

【0172】 [実施例29] 5-(5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -3-ベンゾ[b] チエニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(5-イオド-3-ベンソ [b] チェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラソールの合成

5-(5-dオド-3-ベンソ [b] チエニル) -1H ーテトラゾールを実施例 1 の工程 3 と同様に処理し、5 -(5-dオド-3-ベンゾ [b] チエニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを得た。

融点 $134\sim136$ $^{\circ}$ (再結晶溶媒: クロロホルムー $n- \wedge + \psi \nu$); NMR $(400 Mz, CDC1_3)$ δ ppm 3.80 (3H, s), 5.80 (2H, s), 6.91 $^{\circ}$ \sim 6.94 (2H, m), 7.42 $^{\circ}$ 7.45 (2H, m), 7.64 (1H, d), 7.70 (1H, dd), 8.27 (1H, s), 9.09 (1H, d).

【0173】(工程2) 5-(5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-3-ベンゾ [b]チエニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2 H-テトラゾールの合成

5-(5-イオド-3-ベンゾ [b] チエニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -3-ベンゾ [b] チエニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを褐色油状物として得た。

NMR $(400 \, \text{Mz}, \, \text{CDCl}_3)$ $\delta \, \text{ppm}$ 1. 95 $\sim 2. \, 12 \, (2 \, \text{H}, \, \text{m})$, 2. $30 \sim 2. \, 41 \, (4 \, \text{H}, \, \text{m})$, 3. $67 \sim 3. \, 75 \, (1 \, \text{H}, \, \text{m})$, 3. $79 \, (3 \, \text{H}, \, \text{s})$, 5. $83 \, (2 \, \text{H}, \, \text{s})$, 6. $91 \sim 6. \, 93 \, (2 \, \text{H}, \, \text{m})$, 7. $44 \sim 7. \, 46 \, (2 \, \text{H}, \, \text{m})$, 7. $62 \, (1 \, \text{H}, \, \text{d})$, 7. $89 \, (1 \, \text{H}, \, \text{d})$, 8. $37 \, (1 \, \text{H}, \, \text{s})$, 8. $99 \, (1 \, \text{H}, \, \text{d})$.

【0174】(工程3) 5-(5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-3-ベンゾ[b]チエニル)-1H-テトラゾールの合成5-(5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-3-ベンゾ[b]チエニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 125~127℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); IRνmax cm⁻¹ 2212; NMR (400Mz, DMSO-d₆) δppm1.90 ~2.08(2H, m), 2.28~2.32(4H, m), 3.64~3.72(1H, m), 7.54(1H, s), 7.75(1H, dd), 8.28(1H, d), 8.67(1H, s), 8.93(1H, d); MS(FAB) m/z 364(M⁺+1); 元素分析値C₁₈H₁₃N

5 S₂ の計算値(%) C, 59.48; H, 3.6 1; N, 19.27, 測定値(%) C, 59.4 4; H, 3.40; N, 17.13.

【0175】 [実施例30] 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -5-ベン ゾ [b] チエニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオド-5-ベンソ [b] チエニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラソールの合成

融点 155~157℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400Mz, CDCl₃) δppm 3.80 (3H, s), 5.77 (2 H, s), 6.90~6.93 (2H, m), 7.41~7.43 (2H, m), 7.67 (1 H, s), 7.94 (1H, d), 8.16 (1H, d), 8.52 (1H, s). 【0176】 (工程2) 5-(3-(2-(4-シク

ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) -5ーベンゾ [b] チエニル) -1 Hーテトラゾールの合成 5-(3ーイオド-5ーベンゾ [b] チエニル) -2-(4ーメトキシベンジル) -2 Hーテトラゾールと4ーシクロブチルー2ーエチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、引き続き実施例1の工程5と同様に脱ベンジル化反応を行い、表題物を得た。

融点 195~197℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\wedge + \psi \nu$); IR $\nu \max c m^{-1}$ 2212; N MR (400Mz, DMSO- d_6) $\delta ppm1$. 88 ~ 2.05 (2H, m), 2.21 ~ 2.36 (4 H, m), 3.67 \sim 3.75(1H, m), 7. 60 (1H, s), 8. 16 (1H, d), 8.38 (1H, d), 8.58 (1H, s), 8.62 (1H, s); MS (FAB) m /z 364 (M⁺ +1); 元素分析値C₁₈H₁₃N₅ S₂・H₂Oの計算値(%) C, 58.04; H, 3.79; N,18.80, 測定値(%) C,5 8. 28; H, 3. 56; N, 18. 67. 【0177】 [実施例31] 5-(6-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) -2, 4-ジオキソー1, 2, 3, 4ーテトラヒドロキナゾリンー 3-イル) -1H-テトラゾール:

(工程1) N-(1-(4-メトキシベンジル)-1
 H-テトラゾール-5-イル)-2-アミノ-5-イオドーベンズアミド、及び N-(2-(4-メトキシベンジル)-2-H-テトラゾール-5-イル)-2-アミノ-5-イオドーベンズアミドの合成

N-(1H-テトラゾール-5-イル)-2-アミノ-5-イオドーベンズアミドを実施例1の工程3と同様に処理し、<math>N-(1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール-5-イル)-2-アミノ-5-イオドーベンズアミド、及び <math>N-(2-(4-メトキシベンジル)-2-H-テトラゾール-5-イル)-2-アミノ-5-イオドーベンズアミドを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 3. 7 5 (3H s), 5. 80 (2H, s), 6. 6 1 (1H, d), 6. 70~6. 80 (2H, b r), 6. 93 (2H, d), 7. 39 (2H, d), 7. 50 (1H d), 7. 97 (1H, br s), 8. 02 (1H, d).

【0178】(工程2) 5-(6-イオド-2,4-ジオキソ-1,2,3,4-テトラヒドロキナゾリン-3-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

上記、ヨウ素体1.4gをDMF10mlに溶解し、1,1'ーカルボニルジイミダゾール0.62gを加え80℃で2時間撹拌した。冷却後、反応液を1N塩酸100mlに注ぎ、酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:nーヘキサ:一酢酸エチル=2:1)で精製し、5-(6-イオド-2,4-ジオキソ-1,2,3,4-テトラヒドロキナゾリン-3-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを黄色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 3. 8 2 (3H s), 5. 79 (2H, s), 6. 6 3 (2H, dd), 6. 70~6. 80 (1H, m), 7. 10 (2H, d), 7. 38 (1H, d), 7. 89 (1H dd), 8. 31 (1 H, d).

【0179】 (工程3) 5-(6-(2-(4-シ)0-2)) ロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) -2, 4-ジオキソー1, 2, 3, 4-テトラヒドロキナゾリンー3ーイル) <math>-2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成

5-(6-7)オドー2, 4-3オキソー1, 2, 3, 4-7トラヒドロキナゾリンー3-7ル)-2-(4-1)トキシベンジル)-2 Hーテトラゾールと4-30 ロブチルー2-1 チルー2ーエチニルチアゾールを実施例10 工程4 として同様に処理し、5-(6-(2-(4-3))7 エチニル)-20 (4-31 アンリル)エチニル)-21, 21, 31, 4-71 トラヒドロキナゾリン-31 イル)-21 (4-11 トキシベンジル)-21 Hーテトラゾール 褐色油状物としてを得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1. 9 0~2. 00 (1H, m), 2. 00~2. 10 (1

H, m), 2.20~2.40(4H, m),
3.61(3H, s), 3.60~3.70(1
H, m), 5.79(2H, s), 6.65
(2H, d), 7.00(1H, s), 7.0
0~7.10(1H, m), 7.12(2H, d), 7.37(1H, d), 7.77(1H, dd), 8.21(1H, d).
【0180】(工程4) 5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2,4-ジオ

【0180】 (工程4) 5- (6- (2- (4-シ) ロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) -2, 4-ジオ キソー1, 2, 3, 4-テトラヒドロキナゾリン-3-イル) -1H-テトラゾールの合成

5-(6-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -2, 4-ジオキソ-1, 2, 3, 4-テトラヒドロキナゾリン-3-イル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点>300℃; NMR(400MHz,DMSO- d_6) δ ppm 1.80 \sim 1.90(1H, m), 1.90 \sim 2.10(1H, m), 2.20 \sim 2.40(4H, m), 3.60 \sim 3.70(1H, m), 7.32(1H, d), 7.52(1H, s), 7.50 \sim 7.60(1H, br), 7.99(1H, dd), 8.13(1H, d), 12.10(1H, br); MS(FAB)m/z 392(M^+ +1); 元素分析値 $C_{18}H_{13}N_7O_2$ S·3/2H2 Oの計算値(%) C,55.38;H,4.13; N,17.94, 测定値(%) C,55.59; H,3.86; N,17.78.

【0181】 [実施例32] 5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -4-オキソ-3, 4-ジヒドロキナゾリン-3-イル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(6-イオド-4-オキソ-3, 4-ジヒドロキナゾリン-3-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

N- (1- (4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾール-5-イル) -2-アミノ-5-イオドーベンズアミド、及び N- (2- (4-メトキシベンジル) -2 H-テトラゾール-5-イル) -2-アミノ-5-イオドーベンズアミドの混合物200mgにオルトぎ酸エチル1.8mlを加え、8時間加熱撹拌した。反応液を濃縮し得られる残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製し、5-(6-イオド-4-オキソ-3,4-ジヒドロキナゾリン-3-イル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを油状物として得た

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 3.8$ 1 (3H, s), 5.80 (2H, s), 6. 93 (2H, dd), 7.43 (2H, d), 7.50 (1H, d), 8.10 (1H, d d), 8.27 (1H, s), 8.69 (1H, d).

【0182】(工程2) 5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニルー4ーオキソー3,4-ジヒドロキナゾリン-3-イル)-2-(4ーメトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成5-(6-イオド-4-オキソ-3,4-ジヒドロキナゾリン-3-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4ーシクロブチルー2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4として同様に処理し、5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニルー4ーオキソー3,4-ジヒドロキナゾリンー3-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを褐色油状物としてを得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.9$ $0\sim2.00 (1H, m), 2.00\sim2.10 (1H, m), 2.20\sim2.40 (4H, m), 3.61 (3H, s), 3.60\sim3.70 (1H, m), 5.79 (2H, s), 6.65 (2H, d), 7.00 (1H, s), 7.4 (2H, d), 7.50 (1H, d), 8.10 (1H, dd), 8.27 (1H, s), 8.69 (1H, d).$

【0183】(工程3) 5-(6-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-4-オキソー3,4-ジヒドロキナゾリン-3-イル)-1H-テトラゾールの合成

5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル-4-オキソ-3, 4-ジヒドロキナゾリン-3-イル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H -テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 189~190℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノール); IR v max c m⁻¹ 1956, 1886, 1550, 1290, 1048; NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ p p m 1.80~1.90 (1H, m), 1.90~2.00 (1H, m), 2.20~2.40 (4H, m), 3.50~3.60 (1H, m), 7.52 (1H, s), 7.84 (1H, d), 8.10 (1H, s), 8.25 (1H, dd), 8.39 (1H, d), 12.60 (1H, br s); MS (FAB) m/z 394 (M⁺ +1).

【0184】 [実施例33】 5-(6-(2-(4-5-2))) -4-5-5-2

【0184】 [実施例33] 5-(6-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) -4-オキ ソ-3H-トリアジン-3-イル) -1H-テトラゾー ル:

(工程1) 5-(6-イオド-4-オキソー3H-ト

リアジン-3-イル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成

N-(1-(4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾールー5ーイル) -2-アミノー5ーイオドベンズアミド、及びN-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールー5ーイル) -2-アミノー5ーイオドベンズアミドの混合物300mgに5.3%硫酸1.2m 1及びエタノール0.2mlを加え、0~5℃で亜硝酸ナトリウム56mgを加え、4時間撹拌した。反応液を大水100mlに注ぎ析出結晶をろ取、水洗後、乾燥し、5-(6-イオドー4ーオキソー3H-トリアジンー3ーイル) -2-(4-メトキシベンジル) -2Hーテトラゾールを黄色カラメル状油状物として得た。NMR(400MHz, CDCl₃) δ ppm 3.76 (3H, s), 6.04 (2H, s), 6.99 (2H, dd), 7.45 (2H, d), 8.07 (1H, d), 8.52 (1H, d

d), 8.59(1H, d).
【0185】(工程2) 5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-4-オキソー3H-トリアジン-3-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5- (6-イオド-4-オキソ-3H-トリアジン-3-イル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4として同様に処理し、5- (6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -4-オキソ-3H-トリアジン-3-イル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを褐

色油状物としてを得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.9$ $0\sim2.00(1H, m), 2.00\sim2.10(1H, m), 2.20\sim2.40(4H, m), 3.61(3H, s), 3.60\sim3.70(1H, m), 6.04(2H, s), 7.00(1H, s), 7.12(2H, dd), 7.20(2H, d), 8.07(1H, d), 8.60(1H, dd), 8.63(1H, d).$

【0186】(工程3) 5-(6-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-4-オキソー3H-トリアジン-3-イル)-1H-テトラゾールの合成

5-(6-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -4-オキソ-3H-トリアジン-3-イル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラプール実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た

融点 189~190℃ (再結晶溶媒:水-エタノール); IRvmax cm⁻¹1618, 1550, 139

4, 1290, 996; NMR $(400MHz, DMSO-d_6)$ δppm 1.80~1.90 (1H, m), 1.90~2.00 (1H, m), 2.20~2.40 (4H, m), 3.50~3.60 (1H, m), 7.50 (1H, s), 7.99 (1H, d), 8.55 (1H, dd), 8.58 (1H, d), 12.56 (1H, brs); MS (FAB) m/z 377 (M^++1) ; 元素分析值 $C_{17}H_{12}N_8$ OS· H_2 Oの計算値 (%) C,51.77; H,3.58; N,28.41, 測定値 (%) C,52.01; H,3.60; N,28.79. (0187) [実施例34] 5-(7-(2-(4-1)))

【0187】 [実施例34] 5-(7-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -3-メト キシーベンゾ [b] チオフェン-2-イル) -1H-テ トラゾール:

(工程1) 5-(7-イオド-3-メトキシーベンゾ[b] チオフェン-2-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(7-dオド-3-メトキシーベンゾ [b] チオフェンー2ーイル) -1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、<math>5-(7-dオド-3-メトキシーベンゾ [b] チオフェンー2ーイル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを得た。

融点 156~158℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 3) δppm 3.80 (3H, s), 4.07 (3H, s), 5.77 (2H, s), 6.9 0~6.92 (2H, m), 7.16 (1H,

t), 7.41 \sim 7.43(2H, m), 7.78(1H, d), 7.87(1H, d); MS(EI) m/z478(M $^+$); 元素分析值 $C_{18}H_{15}$ IN₄O₂の計算値(%) C, 45.20; H, 3.16; N, 11.72, 測定値(%) C, 45.40; H, 3.28; N, 11.48.

【0188】(工程2) 5-(7-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-3-メトキシーベンゾ[b]チオフェン-2-イル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成5-(7-イオド-3-メトキシーベンゾ[b]チオフ

5- (7-イオド-3-メトキシーベング [b] チオフェン-2-イル) -2- (4-メトキシベングル) -2 H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4として同様に処理し、5- (7- (2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -3-メトキシーベング [b] チオフェンー2-イル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テト

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 1.9 5~2.07 (2H, m), 2.31~2.42 (4H, m), 3.68~3.77 (1H, m),

ラゾールを褐色油状物としてを得た。

3. 80 (3H, s), 4. 09 (3H, s), 5. 78 (2H, s), 6. 89~6. 93 (2H, m), 7. 01 (1H, s), 7. 41~7. 45 (2H, m), 7. 67 (1H, dd), 7. 88 (1H, dd).

【0189】(工程3) 5-(7-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-3-メトキシーベンゾ[b]チオフェン-2-イル)-1H-テトラゾールの合成

5- (7- (2- (4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -3-メトキシーベンゾ [b] チオフェンー2-イル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H -テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を橙褐色結晶性粉末として得た。

融点 $156\sim158$ C (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\wedge$ キサン); NMR (400MHz, DMSO- d_6) δ ppm $1.88\sim2.02$ (2H, m), $2.24\sim2.34$ (4H, m), $3.67\sim3.76$ (1H, m), 4.16 (3H, s), $7.61\sim7.65$ (2H, m), 7.89 (1H, d), 8.16 (1H, d); MS (FAB) m/2394 (M^+ +1); 元素分析値 $C_{19}H_{15}N_5$ OS $_2 \cdot 1/4H_2$ Oの計算値 (%) C,57.34; H, 3.93; N, 17.60, 測定値 (%) C,57.33; H, 3.93; N, 17.49.

(工程1) 5-(3-4)オドー6-7ルオロフェニル) -2-(4-1) トキシベンジル) -2 Hーテトラゾールの合成

融点 99~101℃ (再結晶溶媒:クロロホルム-n ーへキサン); NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 3.80(3H, s), 5.77(2 H, s), 6.89~6.92(2H, m), 7.39~7.42(2H, m), 7.71~7. 75(1H, m), 8.41~8.43(1H, m).

【0191】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-フルオロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-イオド-6-フルオロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4

として同様に処理し、5-(3-(2-(4-シクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) <math>-6-フルオロフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを得た。

融点 $126\sim128$ C (再結晶溶媒:クロロホルムー $n- \wedge + \psi \nu$); NMR (400 MHz, CDC 1_3) δ p p m 1. $89\sim2$. 42 (6 H, m), 3. $66\sim3$. 74 (1 H, m), 3. 80 (3 H, s), 5. 78 (2 H, s), 6. $90\sim6$. 93 (2 H, m), 6. 97 (1 H, s), 7. $21\sim7$. 26 (1 H, m), 7. $41\sim7$. 43 (2 H, m), 7. $63\sim7$. 67 (1 H, m), 8. $35\sim8$. 38 (1 H, m).

【0192】(工程3) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-フルオロフェニル)-1H-テトラゾールの合成

5- (3- (2- (4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-フルオロフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $223\sim225$ C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーnーへキサン); IR ν max cm $^{-1}$ 3080, 2220, 1620, 1556, 1508; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ pp m 1.84 \sim 2.35 (6H, m), 3.64 \sim 3.72 (1H, m), 7.56 (1H, s), 7.62 \sim 7.66 (1H, m), 7.94 \sim 7.98 (1H, m), 8.30 \sim 8.32 (1H, m); MS (FAB) m/z326 (M $^+$ + 1); 元素分析値C₁₆H₁₂FN₅ Sの計算値(%) C,59.06; H,3.72; N,21.52, 測定値(%) C,59.01; H,3.84; N,21.76.

【0193】 [実施例36] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -4-メチ ルフェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオド-4-メチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-4オド-4-メチルフェニル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、<math>5-(3-4) (3 -4オド-4-メチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 136~138℃ (再結晶溶媒: エーテルー n ー へキサン); NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 2.74 (3H, s), 3.80 (3H, s), 5.72 (2H, s), 6.90 (2H, d), 7.31 (1H, d), 7.37 (2H, d), 7.99 (1H, dd), 8.77 (1H, d).

【0194】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-4-メチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -4-メチルフェニル) -2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4として同様に処理し、5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -4-メチルフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを褐色油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.9$ $0\sim2.11(2H, m), 2.27\sim2.43(4H, m), 2.57(3H, s), 3.71$ (1H, m), 3.80(3H, s), 5.7 3(2H, s), 6.91(2H, d), 6. 97(1H, s), 7.34(1H, d), 7. 40(2H, d), 8.04(1H, dd),8.32(1H, d).

【0195】(工程3) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-4-メチルフェニル)-1H-テトラゾールの合成 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-4-メチルフェニル)-2-(4-メ

ル) エチニル) -4-メチルフェニル) -2-(4-メ トキシベンジル) -2 H-テトラゾールを実施例 1 の工 程 5 と同様に処理し、表題物を得た。

融点 180~182℃ (再結晶溶媒:水-エタノール); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.91~2.08 (2H, m), 2.22~2.34 (4H, m), 2.57 (3H, s), 3.69 (1H, m), 7.47 (1H, s), 7.57 (1H, d), 8.04 (1H, d), 8.25 (1H, s); 元素分析値 C₁₇H₁₅N₅ Sの計算値 (%) C, 63.53; H, 4.70; N, 21.79, 測定値 (%) C, 63.30; H, 4.83; N, 20.99.【0196】[実施例37] 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-4-メト

(工程1) 5-(3-イオド-4-メトキシフェニル)-2-(4-(メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

キシフェニル) -1H-テトラゾール:

5- (3-イオド-4-メトキシフェニル) -1H-テトラゾールを実施例1の工程3として同様に処理し、5- (3-イオド-4-メトキシフェニル) -2- (4- メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを得た。
融点 125~126℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC13) δppm 3.80 (3H, s), 3.93

(3H, s), 5.71 (2H, s), 6.8

8 (1H, d), 6. 91 (2H, d), 7. 3 7 (2H, d), 8. 09 (1H, dd), 8. 54 (1H, d).

【0197】(工程2)5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-4-メトキシフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-イオド-4-メトキシフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロプチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4として同様に処理し、5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-4-メトキシフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 99~100℃ (再結晶溶媒:エーテルーnへ キサン); NMR (400MHz, CDCl₃) δ p pm 1.89~2.10 (2H, m), 2.27 ~2.41 (4H, m), 3.73 (1H, m), 3.80 (3H, s), 3.96 (3H, s), 5.72 (2H, s), 6.91 (2

H, d), 6.95(1H, s), 6.99 (1H, d), 7.39(2H, d), 8.13 (1H, dd), 8.31(1H, d).

【0198】 (工程3) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -4-メトキシフェニル) -1H-テトラゾールの合成

5- (3- (2- (4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -4-メトキシフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 215~217℃ (再結晶溶媒:エタノールーエーテル); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.85~2.06 (2H, m), 2.1 9~2.34 (4H, m), 3.68 (1H, m), 3.99 (3H, s), 7.40 (1H,

d), 7.55(1H, s), 8.15(1H, dd), 8.23(1H, d); 元素分析値 $C_{17}H_{15}N_5OS \cdot 1 / 4H_2$ Oの計算値(%) C, 58.94; H, 4.66; N, 20.22, 測定値(%) C, 59.36; H, 4.63; N, 19.90.

(工程1) 5-(3-7) (4-メトキシベンジル) オキシフェニル) -2-(4-1) (4-メトキシベンジル) -2H-7 トラゾールの合成

5-(3-イオド-6-ヒドロキシフェニル)-1H-テトラゾールを2等量の4-メトキシベンジル クロリ ド及び炭酸カリウムを用い、実施例1の工程3と同様に 処理し、5-(3-4オド-6-(4-メトキシベンジル) オキシフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを得た。

融点 159~160℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 3) δppm 3.79 (3H, s), 3.81 (3H, s), 5.10 (2H, s), 5.7 5 (2H, s), 6.84 (1H, d), 6.8 5 (2H, d), 6.87 (2H, d), 7.34 (2H, d), 7.35 (2H, d), 7.64 (1H, dd), 8.27 (1H, d).

【0200】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-(4-メトキシベンジル)オキシフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成5-(3-イオド-6-(4-メトキシベンジル)オキシフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロプチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4として同様に処理し、5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-(4-メトキシベンジル)オキシフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール

を得た。

を得た。

融点 159~160°C (再結晶溶媒:クロロホルムn-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1
3) δppm 1.88~2.10(2H, m),
2.26~2.41(4H, m), 3.68(1
H, m), 3.79(3H, s), 3.81
(3H, s), 5.17(2H, s), 5.74
(2H, s), 6.87(2H, d), 6.8
8(2H, d), 6.92(1H, d), 7.
07(1H, d), 7.35(2H, d),
7.39(2H, d), 7.62(1H, d
d), 8.23(1H, d).
【0201】(工程3) 5-(3-(2-(4-シク

ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) -6-ヒドロキシフェニル) -1H-テトラゾールの合成 5-(3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) -6-(4-メトキシベンジル) オキシフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物

融点 205~209℃ (decomp.) (再結晶溶媒:エタノールーエーテル); NMR (400MH z, DMSO-d₆) δppm 1.84~2.03 (2H, m), 2.18~2.33 (4H, m), 3.66 (1H, m), 7.15 (1H, d), 7.49 (1H, s), 7.70 (1H, dd), 8.44 (1H, d); 元素分析値C

16H₁₃N₅ OSの計算値(%) C, 57.82; H, 4.25; N, 21.07, 測定値(%) C, 57.43; H, 4.32; N, 20.79. 【0202】 [実施例39] 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-フルオロフェニル)-1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオド-2-フルオロフェニル)-1H-テトラゾールの合成

2,6-ルチジン1.65gに氷冷撹拌下にトリフルオロ酢酸0.32mlを加えた。同温度で0.5時間撹拌した後、アジ化ナトリウム270mgを加え、室温で1時間撹拌した。これに3-イオド-2-フルオロベンゾニトリル1gを加え、80℃で16時間撹拌した。反応液を2N塩酸50mlに加え、析出結晶をろ取、水洗後、乾燥した。粗結晶をクロロホルム-エタノールから再結晶し、5-(3-イオド-2-フルオロフェニル)-1H-テトラゾール1.05gをプリズム晶として得た。

融点 $182 \sim 184 \, ^{\circ}$; NMR $(400 \, \text{MHz}, DM \, \text{SO-d}_{6})$ $\delta \, \text{ppm7}.$ $25 \, (1 \, \text{H}, m)$, 8. $16 \, (1 \, \text{H}, m)$, 8. $21 \, (1 \, \text{H}, m)$; MS $(E\, I)$ m/z $290 \, (\text{M}^{+})$; 元素分析値 C_{7} H₄ $F\, I\, \text{N}_{4}$ の計算値 (%) C, 28. 99; H, 1. 39; N, 19. 32, 測定値 (%) C, 29. 26; H, 1. 59; N, 19. 05.

【0203】(工程2) 5-(3-イオド-2-フルオロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H -テトラゾールの合成

5-(3-4オド-2-7) -1H-7 トラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(3-4オド-2-7) -2H-7 トキシベンジル)-2H-7 トラゾールを得た。

融点 $124\sim126$ °C; NMR (400MHz, DM $SO-d_6$) $\delta ppm3$. 75(3H, s), 5. 95(2H, s), 6.97(2H, d), 7.18(1H, t), 7.40(2H, d),

8.03 (2H, m); MS (EI) m/z 4 10 (M^+); 元素分析値 $C_{15}H_{12}FIN_4$ Oの計算値(%) C, 43.92; H, 2.95; N, 1 3.66, 測定値(%) C, 43.89; H, 3.02; N, 13.83.

【0204】 (工程3) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-フルオロフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成

5- (3-イオド-2-フルオロフェニル) -2- (4 -メトキシベンジル) -2H-テトラゾールと4ーシク ロプチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4 として同様に処理し、5- (3- (2- (4-シクロプ チル-2-チアゾリル) エチニル) -2-フルオロフェ -2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 114~116℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 $_3$) δ ppm 1.92~2.40 (6H, m), 3. $66\sim3$. 75 (1H, m), 3. 80 (3 H, s), 5.78 (2H, s), 6.89 \sim 6.93 (2H, m), 6.99 (1H, s), 7. 27 (1H, t), 7. $40 \sim 7$. 43 (2) H, m), 7. $65 \sim 7$. 69 (1 H, m), 8. $13 \sim 8$. 17 (1H, m); MS (FAB) m /z 445 (M⁺ +1); 元素分析値C₂₄H₂₀F N₅ OSの計算値 (%) C, 64. 70; H, 4. 52; N, 15.72, 測定値(%) C, 64. 73; H, 4. 56; N, 15. 81. 【0205】(工程4) 5-(3-(2-(4-シク ロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) -2-フルオロ フェニル) -1H-テトラゾールの合成 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリ ル) エチニル) -2-フルオロフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例1の 工程5と同様に処理し、表題物を得た。

(工程1) 5-(3-4

ルチオフェニル) -1H-テトラゾール:

5- (3-イオド-2-フルオロフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール204mgをDMSO10mlに溶解し、メタンチオールナトリウム塩(約15%含有水溶液)0.5mlを加え、室温で3時間撹拌した。反応液を、1N塩酸100mlに注ぎ、析出結晶をろ取、水洗後、乾燥した。粗結晶をクロロホルム-n-ヘキサンから再結晶し、5- (3-イオド-6-メチルチオフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール183mgを針状晶として得た。

融点138~140℃; NMR (400MHz, CD

 Cl_3) δ ppm 2. 46 (3H, s), 3. 8 0 (3H, s), 5. 77 (2H, s), 6. 8 9 ~ 6. 91 (2H, m), 7. 05 (1H, d), 7. 69 (1H, dd), 8. 29 (1 H, d); MS (EI) m/z 438 (M⁺); 元素分析值 $C_{16}H_{15}I$ N₄ OSの計算值 (%) C, 43. 85; H, 3. 45; N, 12. 78, 測定值 (%) C, 44. 17; H, 3. 55; N, 12. 91.

【0.207】 (工程2) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-メチルチオフェニル) -1 H-テトラゾールの合成

5-(3-イオド-6-メチルチオフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4として同様に処理し、引き続き、実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 114~116℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノール); IRνmax cm⁻¹ 2216; NM R (400MHz, DMSO-d₆) δppm1. 86~2. 32(6H, m), 2. 67(3H, s), 3. 63~3. 71(1H, m), 7. 5

3 (1 H, s), 7.57 (1 H, t), 7.82 (1 H, dd), 7.99 (1 H, d); MS (FAB) m/z 354 (M $^+$ +1); 元素分析值 $C_{17}H_{15}N_5$ S₂ の計算値(%) C, 57.77; H, 4.28; N, 19.81, 測定値(%) C, 57.31; H, 4.34; N, 19.65.

【0208】 [実施例41] 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-クロロフェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(6-クロロ-3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(6-クロロ-3-イオドフェニル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(6-クロロ-3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点90~91°C; NMR (400MHz, CDC1 $_3$) δ p p m 3.80 (3H, s), 5.77 (2H, s), 6.89 (2H, d), 7.2 3 (1H, d), 7.39 (2H, d), 7.68 (1H, d), 8.25 (1H, d).

【0209】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-クロロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5- (6-クロロ-3-イオドフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールと4-シクロ プチルー2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、5-(3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル)エチニル)-6-クロロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 66~67℃ (再結晶溶媒:エーテルーnーへキサン); NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.88~2.11 (2H, m), 2.26~2.42 (4H, m), 3.69 (1H, m), 3.81 (3H, s), 5.79 (2H, s), 6.91 (2H, d), 6.97 (1H, s), 7.41 (2H, d), 7.51 (1H, d), 7.58 (1H, dd), 8.17

【0210】(工程3) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-クロロフェニル)-1H-テトラゾールの合成

(1 H,

d) .

5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-クロロフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

【0211】 [実施例42] 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-クロロフェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(2-クロロ-3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成

5- (2-クロロ-3-イオドフェニル) -1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5- (2-クロロ-3-イオドフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを得た。

融点 $91\sim92$ °C; NMR (400MHz, CDC l_3) δ ppm 3.76 (3H, s), 5.78 (2H, s), 6.90 (2H, d), 7.06 (1H, t), 7.40 (2H, d), 7.8 2 (1H, d), 7.99 (1H, d).

【0212】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-クロロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テト

ラゾールの合成

(1H, d).

5-(2-クロロ-3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロプチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4として同様に処理し、5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-クロロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 69~70℃ (再結晶溶媒: エーテルー n - へキサン); NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.89~2.11 (2H, m), 2.26~2.40 (4H, m), 3.72 (1H, m), 3.80 (3H, s), 5.79 (2H, s), 6.91 (2H, d), 7.00 (1H, s), 7.34 (1H, t), 7.41 (2H, d), 7.72 (1H, d), 7.97

【0213】(工程3) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-クロロフェニル)-1H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-クロロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $167\sim170$ $^{\circ}$ (再結晶溶媒:水-エタノール); $IR\nu$ max $cm^{-1}2220$; NMR (400 MHz, $DMSO-d_6$) δ p p m 1. $83\sim2$. 10 (2H, m), 2. $19\sim2$. 35 (4H, m), 3. 70 (1H, m), 7. 61 (1H, s), 7. 65 (1H, t), 7. 92 (1H, dd), 8. 02 (1H, dd); MS (EI) m/z 341 (M^+); 元素分析値 $C_{16}H_{12}$ N_5 C1SO計算値(%) C, 56. 22; H, 3. 54; N, 20. 49, 測定値(%) C, 56. 6. 35; 100

【0214】 [実施例43] 5-(3-(2-(4-イソプロピル-2-チアゾリル) エチニル) -2-フル オロフェニル) -1H-テトラゾール

実施例39で合成した、5-(3-イオド-2-フルオロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2Hーテトラゾールと4-イソプロピルー2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、5-(3-(2-(4-イソプロピルー2-チアゾリル)エチニル)-2-フルオロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点116~119℃; NMR (400MHz, CD

 Cl_3) δ p p m 1. 35 (6 H, d), 3. 1 2 ~ 3. 19 (1 H, m), 3. 80 (3 H, s), 5. 78 (2 H, s), 6. 89 ~ 6. 9 2 (2 H, d), 6. 98 (1 H, s), 7. 2 7 (1 H, t), 7. 39 ~ 7. 41 (2 H, d), 7. 64 ~ 7. 68 (1 H, m), 8. 1 2 ~ 8. 17 (1 H, m); MS (EI) m/z 4 3 3 (M⁺); 元素分析値 $C_{23}H_{20}FN_5$ OSの計算値 (%) C, 6 3. 7 3; H, 4. 6 5; N, 1 6. 1 6, 測定値 (%) C, 6 3. 6 9; H, 4. 6 9; N, 1 6. 2 2. 【0 2 1 5】 (工程2) 5 - (3 - (2 - (4 - 7))

【U215】 (工程2) 5- (3- (2- (4-1) プロピルー2-チアゾリル) エチニル) -2-フルオロフェニル) -1H-テトラゾールの合成 5- (3-イオド-2-フルオロフェニル) -2- (4

ーメトキシベンジル) -2H-テトラゾールと4-イソ プロピル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程5 と同様に処理し、表題物を得た。

融点 155~158℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); IR v max c m⁻¹ 2220; NM R (400MHz, DMSO-d₆) δ p p m 1. 28 (6H, d), 3.07~3.16 (1H,

m), 7.55 (1H, t), 7.58 (1H, s), 7.97 \sim 8.00 (1H, m), 8.17 \sim 8.20 (1H, m); MS (EI) m/z 313 (M $^+$); 元素分析値 $C_{15}H_{12}FN_5$ Sの計算値 (%) C,57.49; H,3.86; N,22.35, 測定値 (%) C,57.50; H,3.95; N,22.29.

(工程1) 5-(3-(2-(4-n-プロピル-2-チアゾリル) エチニル) -2-フルオロフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成

実施例39で用いた、5-(3-イオド-2-フルオロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと<math>4-n-プロピル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、5-(3-(2-(4-n-プロピル-2-チアゾリル)エチニル)-2-フルオロフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 $97\sim 99$ °C; NMR (400MHz, CDC1 $_3$) δ ppm 0. 98 (3H, t), 1. 78 (2H, m), 2. 80 (2H, t), 3. 8 0 (3H, s), 5. 78 (2H, s), 6. $89\sim 6$. 91 (2H, d), 6. 98 (1H, s), 7. 27 (1H, t), 7. $40\sim 7$. 4 2 (2H, d), 7. $64\sim 7$. 68 (1H,

m), 8.12~8.16(1H, m); MS (EI) m/z 433(M⁺); 元素分析値C₂₃H ₂₀FN₅ OSの計算値(%) C, 63.73; H, 4.65; N, 16.16, 測定値(%) C, 63.58; H, 4.71; N, 16.02. 【0217】(工程2) 5-(3-(2-(4-n-プロピル-2-チアゾリル)エチニル)-2-フルオロフェニル)-1H-テトラゾールの合成5-(3-(2-(4-n-プロピル-2-チアゾリル)エチニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $149 \sim 152 \sim ($ 再結晶溶媒:クロロホルムー $n- \wedge + \psi >)$; $IR \nu \max \ cm^{-1} 2224$; N MR $(400 MHz, DMSO-d_6) \delta ppm0.9$ $2(3H, t), 1.70(2H, m), 2.75(2H, t), 7.55(1H, t), 7.59(1H, s), 7.94 \sim 8.01(1H, m), 8.14 \sim 8.22(1H, m); MS (EI) m/z 313(M+); 元素分析値<math>C_{15}H_{12}FN_5$ Sの計算値(%) C, 57.49; H, 3.86; N, 22.35, 測定値(%) C, 57.47; H, 3.98; N, 22.11. 【0218】 [実施例45] 5-(3-(2-(4-

【0218】 [美施例45] 5- (3- (2- (4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) -2-メチ ルフェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5−(3−イオド−2−メチルフェニル) −2−(4−メトキシベンジル)−2H−テトラゾール の合成

5-(3-4オド-2-メチルフェニル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、<math>5-(3-4)でルクシーのでは、5-(3-4)で

【0219】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-dx)-2-x+nフェニル)-2-(4-x)+22ーパークロットキシベンジル)-2H-F1ーアトラゾールと4-22ープチル-2-x+22ールを実施例10工程42と同様に処理し、5-(3-(2-(4-2)-2)+2)-22ー(4-x+22ーパークロブチルークーグチル)-2-x+22ーパークロブチル)を得た。

融点 140~142℃ (再結晶溶媒:エーテル-n-

へキサン); NMR (400MHz, CDC 1_3) δ ppm 1.88~2.11(2H, m), 2.27~2.42(4H, m), 2.77(3H, s), 3.69(1H, m), 3.81(3H, s), 5.77(2H, s), 6.91(2H, d), 6.97(1H, s), 7.30(1H, t), 7.41(2H, d), 7.67(1H, dd), 7.96(1H, dd); 元素分析値 $C_{25}H_{23}N_5$ OSの計算値(%) C, 68.00; H, 5.25; N, 15.86, 測定値(%) C, 67.83; H, 5.26; N, 15.94.

【0220】(工程3) 5~(3~(2~(4~シクロプチル~2~チアゾリル)エチニル)~2~メチルフェニル)~1H~テトラゾールの合成 5~(3~(2~(4~シクロプチル~2~チアゾリル)エチニル)~2~(4~メ

ル) エチニル) -2-メチルフェニル) -2-(4-メ トキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例1の工 程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 209~211℃ (再結晶溶媒:エタノールーエーテル); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.84~2.06 (2H, m), 2.19~2.34 (4H, m), 2.64 (3H, s), 3.69 (1H, m), 7.52 (1H, t), 7.56 (1H, s), 7.79 (1H, d), 7.85 (1H, d); MS (EI) m/z 321 (M⁺); 元素分析値C₁₇H₁₅N₅ Sの計算値 (%) C, 63.53; H, 4.70; N, 21.79, 測定値 (%) C, 63.44; H, 4.80; N, 21.73.

【0221】 [実施例46] 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-トリ フルオロメチルフェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオド-2-トリフルオロメチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5- (3-イオド-2-トリフルオロメチルフェニル) - 1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5- (3-イオド-2-トリフルオロメチルフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 3.8 1 (3H, s), 5.76 (2H, s), 6. 91 (2H, d), 7.22 (1H, t), 7.36 (2H, d), 7.48 (1H, d), 8.22 (1H, d).

【0222】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-トリフルオロメチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアソリ ル) エチニル) -2-トリフルオロメチルフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールと 4-シクロプチルー2-エチニルチアゾールを実施例1 の工程4と同様に処理し、5-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー2ートリフル オロメチルフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを油状物として得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.9 $0\sim2.11$ (2H, m), 2.26 ~2.43 (4 H, m), $3.63\sim3.77(1H, m)$, 3.81 (3H, s), 5.78 (2H, s), 6. 91 (2H, d), 7. 02 (1H, s), 7.38 (2H, d), 7.57 \sim 7.6 $3 (1 H, m), 7.88 \sim 7.90 (1 H,$ m) . 【0223】(工程3) 5-(3-(2-(4-シク

ロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) -2-トリフル オロメチルフェニル) -1H-テトラゾールの合成 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリ ル) エチニル) -2-トリフルオロメチルフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを 実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。 融点 209~211℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\Lambda + \psi$); IR ν max cm⁻¹ 2224; N MR $(400MHz, DMSO-d_6) \delta ppm1.8$ $9\sim2.04$ (2H, m), 2.21 ~2.35 (1H, m), 3.70 (1H, m), 7.63 (1H, s), 7.80 (1H, d), 7.94 (1H, t), 8.19 (1H, d); MS (FAB) m/z 376 (M⁺ +1); 元素分析 値C₁₇H₁₂F₃ N₅ S・1/2H₂ Oの計算値(%) C, 53. 12; H, 3. 41; N, 18. 2 2, 測定値(%) C, 53.39; H, 3.27; N. 18. 44.

シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ートリ フルオロメチルフェニル) -1H-テトラゾール: (工程1) 5-(3-イオド-6-トリフルオロメチ ルフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成

【0224】 [実施例47] 5-(3-(2-(4-

5-(3-イオド-6-トリフルオロメチルフェニル) -1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理 し、5-(3-イオド-6-トリフルオロメチルフェニ ル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾ ールを得た。

融点59~61℃; NMR (400MHz, CDC1 3) δppm 3.81 (3H, s), 5.77 (2H, s), 6.91 (2H, d), 7.3 8 (2H, d), 7.52 (1H, d), 7.

94 (1H, dd), 8.22 (1H, d). 【0225】(工程2) 5-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ートリフル オロメチルフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリ ル) エチニル) -6-トリフルオロメチルフェニル) -1H-テトラゾールと4-シクロプチル-2-エチニル チアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エ チニル) -6-トリフルオロメチルフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを油状 物として得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.8 $9\sim2.17$ (2H, m), 2.27 ~2.41 (4 H, m), 3.70(1H, m), 3.81 (3H, s), 5.78(2H, s), 6.9 2 (2H, d), 7.00 (1H, s), 7. 39 (2H, d), 7.78 (1H, d), 7. 83 (1H, d), 8.08 (1H, s). 【0226】(工程3) 5-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ートリフル オロメチルフェニル) -1H-テトラゾールの合成 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリ ル) エチニル) -6-トリフルオロメチルフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを 実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。 融点 209~211°C (再結晶溶媒:クロロホルムー エタノールーnーヘキサン); $IR \nu \max c m^{-1} 2$ 224; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δ $ppm 1.84\sim2.06(2H, m), 2.1$ $9\sim2.34$ (1H, m), 3.69 (1H, m), 7.61(1H, s), 8.03~8.1 3 (1H, m), 8.16 (1H, s); MS (FAB) m/z 376 (M⁺ +1); 元素分析 値C₁₇H₁₂F₃ N₅ Sの計算値(%) C, 54.40; H, 3. 22; N, 18. 66, 測定値(%) C, 54. 29; H, 3. 38; N, 18. 41. 【0227】 [実施例48] 5-(3-(2-(4-シクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー5ーメト キシカルボニルフェニル) -1H-テトラゾール: (工程1) 5-(3-イオド-5-メトキシカルボニ ルフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成 -1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理 し、5-(3-イオド-5-メトキシカルボニルフェニ

5-(3-イオド-5-メトキシカルボニルフェニル) ル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾ ールを得た。

融点 97℃; IR v max c m⁻¹ 1728; NM

R (400MHz, CDCl₃) δppm 3.80 (3H, s), 3.95 (3H, s), 5.7 5 (2H, s), 6.91 (2H, d), 7. 39 (2H, d), 8.44 (1H, s), 8.66 (1H, d), 8.74 (1H, s); MS(EI)m/z 450(M⁺); 元素分析値C 17H15 I N4O3 の計算値(%) C, 46.35; H, 3. 36; N, 12. 44, 測定値(%) C, 46.08; H, 3.65; N, 12.50. 【0228】(工程2) 5-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー5ーメトキシ カルボニルフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成 5-(3-イオド-5-メトキシカルボニルフェニル) -2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール と4-シクロブチルー2-エチニルチアゾールを実施例 1の工程4と同様に処理し、5-(3-(2-(4-シ クロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) -5-メトキ シカルボニルフェニル) -2-(4-メトキシベンジ ル) -2H-テトラゾールを褐色油状物として得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.9 $3\sim2.40$ (6H, m), 3.71 (1H, m), 3.81 (3H, s), 3.97 (3H, s), 5.75 (2H, s), 6.92 (2 H, d), 6.99(1H, s), 7.41 (2H, d), 8.32 (1H, d), 8.54 (1H, t), 8.79 (1H, d). 【0229】(工程3) 5-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) -5-メトキシ カルボニルフェニル) -1H-テトラゾールの合成 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリ ル) エチニル) -5-メトキシカルボニルフェニル) -2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを 実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。 融点 189~191℃ (再結晶溶媒:塩化メチレ ν); IR ν max c m⁻¹ 2 2 2 4, 1 7 2 0; NM R (400MHz, DMSO- d_6) δ ppm 1.8 $0\sim2.32$ (6H, m), 3.69 (1H, m), 3.98 (3H, s), 7.60 (1H, 8. 32 (1H, s), 8. 53 (1 s), H, s), 8.68(1H, s); MS(FA B) m/z 366 (M+ +1); 元素分析值C₁₈ H₁₅N₅O₂ Sの計算値(%) C, 59.16; H, 4. 14; N, 19. 17, 測定値(%) C, 58. 79; H, 4. 14; N, 18. 76. 【0230】[実施例49] 5-(3-(2-(4-シクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ーメト キシフェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオド-6-メトキシフェニ

ル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾ

ールの合成 5-(3-イオド-6-メトキシフェニル)-1H-テ トラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(3- / 1) - (4 -) - (4 -)トキシベンジル) -2H-テトラゾールを得た。 融点 133~135℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 $_{3}$) δ p p m 3.80 (3 H, s), 5.76 .(2H, s), 6.80(1H, d), 6.8 $9\sim6.91$ (2H, m), 7.37 ~7.39 (1 H, m), 7.70(1H, dd), 8.20 (1 H, d); MS (EI) m/z 422 (M⁺); 元素分析値C₁₆H₁₅IN₄O₂の計算値 (%) C, 45. 52; H, 3. 58; N, 13. 27, 測定値(%) C, 45. 49; H, 3. 6 8; N, 13. 29. 【0231】(工程2) 5-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ーメトキシ フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成 5- (3-イオド-6-メトキシフェニル) -2- (4 ーメトキシベンジル) -2H-テトラゾールと4-シク ロブチルー2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4 と同様に処理し、5-(3-(2-(4-シクロプチル -2-チアゾリル) エチニル) -6-メトキシフェニ ル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾ ールを得た。 融点98~101℃; NMR (400MHz, CDC l_3) δppm 1. 93~2. 40 (6H, m), 3. 71 (1H, m), 3. $64 \sim 3$. 73 (1

H, m), 3.80(3H, s), 3.96 (3H, s), 5. 77 (2H, s), 6. 89 ~ 6.92 (2H, m), 6.93 (1H, s), 7.03 (1H, d), 7.38 \sim 7.4 2 (2H, m), 7.66 (1H, dd), 8. 17 (1H, d); MS (EI) m/z 45 7(M⁺); 元素分析値 C₂₅H₂₃N₅ O₂ Sの計算値 (%) C, 65. 63; H, 5. 07; N, 1 5.31, 測定值(%) C,65.40; H, 5. 03; N, 15. 45. 【0232】(工程3) 5-(3-(2-(4-シク ロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ーメトキシ フェニル) -1 H-テトラゾールの合成 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリ ル) エチニル) -6-メトキシフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例1の

融点 219~221℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); IRνmax cm⁻¹ 2216; NM R (400MHz, DMSO-d₆) δppm1.86

工程5と同様に処理し、表題物を得た。

 ~ 2.34 (6H, m), 3.63 ~ 3.71 (1H, m), 4.04 (3H, s), 7.39 (1H, d), 7.51 (1H, s), 7.88 (1H, dd), 8.29 (1H, d); MS (EI) m/z 337 (M $^+$); 元素分析値 C_{17} H $_{15}N_5$ OSの計算値 (%) C, 60.52; H, 4.48; N, 20.76, 測定値 (%) C, 60.50; H, 4.60; N, 20.93. 【0233】 [実施例50] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルチオフェニル)-1+1-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオド-2-メチルチオフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5- (3-イオド-2-メチルチオフェニル) -1 H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(3-イオド-2-メチルチオフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを淡黄色油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 2.3$ 0 (3H, s), 3.80 (3H, s), 5. $77 (2H, s), 6.88 \sim 6.92 (2H, m), 7.07 (1H, t), 7.38 \sim 7.4$ 1 (2H, m), 7.61 (1H, dd),8.06 (1H, dd).

【0234】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルチオフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5- (3-イオド-2-メチルチオフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールと4-シクロプチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、5- (3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-メチルチオフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを褐色油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.8$ $9\sim2.40 (6H, m), 2.44 (3H, s), 3.67\sim3.75 (1H, m), 3.8$ 0 (3H, s), 5.79 (2H, s), 6. $89\sim6.91 (2H, m), 6.99 (1H, s), 7.36 (1H, d), 7.40\sim7.4$ 2 (2H, m), 7.69 (1H, dd), 7.73 (1H, dd).

【0235】(工程3) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルチオフェニル)-1H-テトラゾールの合成5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルチオフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例1

の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

【0236】 [実施例51] 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -5-プロ モフェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオド-5-ブロモフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5- (3-イオド-5-ブロモフェニル) -1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5- (3-イオド-5-ブロモフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを得た。

融点 $154\sim155$ C (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\wedge$ キサン); NMR (400 MHz, CDC1 $_3$) δ p p m 3.80 (3 H, s), 5.72 (2 H, s), 6.90 (2 H, d), 7.37 (2 H, d), 7.92 (1 H, t), 8.24 (1 H, t), 8.40 (1 H, t); MS (FAB) m/z 473 (M^+ +1); 元素分析値 $C_{15}H_{12}BrIN_4$ Oの計算値 (%) C, 38.24; H, 2.57; N, 11.90, 測定値 (%) C, 38.25; H, 2.54; N, 12.10.

【0237】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-5-プロモフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5- (3-イオド-5-プロモフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールと4-シクロプチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、5- (3- (2- (4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -5-プロモフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを得た。

融点 127~129℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 3) δppm 1.95~2.09(2H, m), 2.29~2.40(4H, m), 3.68~3. 72(1H, m), 3.80(3H, s), 5.73(2H, s), 6.91(2H, d), 6.99(1H, s), 7.40(1H, d), 7.78(1H, t), $8.29\sim8.39(1H, m)$; $MS(FAB)m/z508[(M^++2)+1)]$, $506[(M^+)+1)]$; 元素分析值 $C_{24}H_{20}BrN_5OS\cdot1/4H_2OO$ 計算值(%) C, 56.42; H, 4.04; N, 13.71, 測定值(%) C, 56.49; H, 4.07; N, 13.69.

【0238】(工程3) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-5-ブロモフェニル)-1H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -5-プロモフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $104\sim105$ C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノールーnーへキサン); I R ν max c m $^{-1}$ 2210; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ p p m 2.06(2H, m), 2.19 \sim 2.32(4H, m), 3.73(1H, m), 7.59(1H, s), 8.14(1H, s), 8.28(1H, s), 8.30(1H, s); MS (FAB) m/z 388[(M $^+$ + 2) + 1)], 386[(M $^+$ + 2) + 1)], 17. 386[(M $^+$ + 2) + 1)], 18; 19. 386[(M $^+$ + 2) + 1)], 19. 386[(M $^+$ + 3)], 19. 386[(M $^+$ + 4)], 19. 38[(M $^$

【0239】 [実施例52] 5-(3,5-ビス(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-テトラゾール:

2; N, 17.88.

(工程1) 5-(3,5-ジイオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成5-(3-プロモ-5-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例16の工程2と同様に処理し、5-(3,5-ジイオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 177~178℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 3) δppm 3.80 (3H, s), 5.72 (2H, s), 6.91 (2H, d), 7.3 7 (2H, d), 8.11~8.12 (1H, m), 8.43 (2H, d).

【0240】(工程2) 5-(3,5-ピス(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラソールの合成

5-(3,5-ジイオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと<math>4-シクロプチル

-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に 処理し、5-(3,5-ビス(2-(4-シクロプチル -2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを茶褐色アモ ルファスとして得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 1. 9 0~2. 11 (4H, m), 2. 28~2. 42 (8 H, m), 3. 66~3. 75 (1H, m), 3. 80 (3H, s), 5. 74 (2H, s), 6. 92 (2H, d), 6. 98 (2H, s), 7. 41 (2H, d), 7. 82 (1H, s), 8. 37 (2H, d).

【0241】(工程3) 5-(3,5-ビス(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1H-テトラゾールの合成

5-(3,5-ビス(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $212\sim214$ C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノールーnーへキサン); I R ν max c m $^{-1}$ 2216; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ p p m 1.85~2.06 (4 H, m), 2.19~2.34 (8 H, m), 3.65~3.73 (2 H, m), 7.59 (1 H, s), 8.16 (1 H, s), 8.36 (2 H, d); MS (FAB) m/z 469 (M $^+$ +1); 元素分析値C₂₅H₂₀N₆S₂·3/4H₂Oの計算値(%) C,62.28; H,4.49; N,17.43, 測定値(%) C,62.46; H,4.38; N,17.49.

【0242】 [実施例53] 5-(5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -3-(1 H-テトラゾール-5-イル) フェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(5-4オド-3-(-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-4ル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(5-dオド-3-(-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-dル)フェニル)-1H-テトラゾールを実施例<math>1の工程3と同様に処理し、5-(5-dオド-3-(-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-dル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 183~186℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 3) δppm 3.80 (6H, s), 5.74 (4H, s), 6.91 (4H, d), 7.3 9 (4H, d), 8. 56 (2H, d), 8. 8 2~8. 83 (1H, m).

【0243】(工程2) 5-(5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-3-(1H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-1H-テトラゾールの合成

5-(5-イオド-3-(-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロプチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、引き続き、これを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 >300℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノールーnーへキサン); IRνmax cm⁻¹ 2220; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.88~2.04 (2H, m), 2.23~2.35 (4H, m), 3.66~3.74 (1H, m), 7.61 (1H, s), 8.46 (2H, d), 8.86~8.87 (1H, m); 元素分析値C₁₇H₁₃N₉ S・1/2H₂ Oの計算値 (%) C,53.12; H,3.67; N,32.79, 測定値 (%) C,53.25; H,4.05; N,33.06.

【0244】 [実施例54] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-メト キシフェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオド-2-メトキシフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(3-4オド-2-メトキシフェニル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、<math>5-(3-4オド-2-メトキシフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 65~69℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーnーへキサン); NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 3.78 (3H, s), 3.80 (3H, s), 5.77 (2H, s), 6.88~6.91 (2H, m), 6.97 (1H, t), 7.39~7.41 (2H, m), 7.90 (1H, dd), 8.02 (1H, dd); MS (EI) m/z422 (M⁺); 元素分析値C₁₆H₁₅IN₄O₂の計算値 (%) C, 45.52; H, 3.58; N, 13.27, 測定値 (%) C, 45.69; H, 3.75; N, 13.48.

【0245】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メトキシフェニル)-1H-テトラゾールの合成

5-(3-イオド-2-メトキシフェニル)-2-(4 -メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シク ロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4 と同様に処理し、引き続き、これを実施例1の工程5と 同様に処理し、表題物を得た。

融点 153~155°C (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\wedge + + \nu$); IR $\nu \max c m^{-1}$ 2216; N MR (400MHz, DMSO- d_6) δ ppm1. 8 $5\sim2.34$ (6H, m), 3.65 ~3.73 (1H, m), 4. 01 (3H, s), 7. 42 (1H, t), 7.59 (1H, s), 7.88 (1H, dd), 8.12(1H, dd); M S(EI) m/z 337(M⁺); 元素分析値C₁₇ H₁₅N₅OSの計算値(%)C, 60.52; H, 4.48; N, 20.76, 測定値(%) C, 6 0. 34; H, 4. 53; N, 20. 60. 【0246】 [実施例55] エチル 4-(2-(4 ーシクロプチルー2ーチアゾリル) エチニルー2ー (1 H-テトラゾール-5-イル) フェノキシアセテート: (工程1) エチル 4-(2-イオド-2-(1-(4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾール-5-イル) フェノキシアセテート 及び エチル 4-(2 ーイオドー2ー (2-(4-メトキシー5ーイル) -2 H-テトラゾール-5-イル) フェノキシアセテートの 合成

4-(2-dオド-2-(1H-テトラゾール-5-d ル) フェノキシアセテートを実施例1の工程3と同様に処理し、4-(2-dオド-2-(1-(4-d+2)) ベンジル)-1H-テトラゾール-5-dル)フェノキシアセテート及び エチル 4-(2-dオド-2-(2-(4-d+2)) フェノキシアセテートを約1:1の混合物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) & ppm 1.2 6 and 1.29 (3H, each t), 3.76 and 3.79 (3H, eachs), 4.23 and 4.25 (2H, each q), 4.59 and 4.70 (2H, s), 5.58 and 5.75 (2H, each s), 6.63 and 6.72 (1H, each d), 6.74~6.76 and 6.88~6.90 (2H, each m), 6.98~7.0 0 and 7.38~7.41'2H, each m), 7.52 (1/2H, d), 7.67 and 7.76 (1H, each dd), 8.27 (1/2H, d).

【0247】(工程2) エチル 4-(2-(4-シ クロプチル-2-チアゾリル) エチニル-2-(1H-テトラゾール-5-イル) フェノキシアセテートの合成 エチル 4-(2-イオド-2-(1-(4-メトキシ ベンジル) -1H-テトラゾール-5-イル) フェノキ シアセテートとエチル 4-(2-イオド-2-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5イル)フェノキシアセテートの混合物(1:1)と4-シクロブチルー2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、引き続き、これを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 176~178℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-へキサン); IRνmax cm⁻¹ 2216, 1730; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ p pm 1.26 (3H, t), 1.84~2.33 (6H, m), 3.63~3.71 (1H, m), 4.17 (2H, q), 5.13 (2H, s), 7.34 (1H, d), 7.52 (1H, s), 7.83 (1H, d), 8.31 (1H, s); MS (EI) m/z 409 (M+); 元素分析値C₂₀H₁₉N₅O₃Sの計算値 (%) C, 58.67; H, 4.68; N, 17.10, 測定値 (%) C, 58.67; H, 4.68; N, 17.16.

【0248】 [実施例56] 4-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニルー2-(1Hーテトラゾールー5-イル) フェノキシ酢酸: エチル 4-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニルー2-(1Hーテトラゾールー5-イル) フェノキシアセテート350mgにTHF5ml及び0.25N水酸化ナトリウム水溶液10mlを加え、室温で1時間撹拌した。反応液を水100mlに注ぎ、1N塩酸10mlを加えた。析出した結晶を、ろ取、水洗後乾燥した。粗結晶をクロロホルムーエタノールから再結晶し、表題物290mgを結晶性粉末として得た。

融点 $251\sim255$ ℃; IR ν max cm $^{-1}$ 2216, 1720; NMR (400MHz, DMSO-d $_6$) δ ppm 1.86 \sim 2.34(6H, m), 3.63 \sim 3.71(1H, m), 5.06(2H, s), 7.34(1H, d), 7.52(1H, s), 7.85(1H, dd), 8.34(1H, d); MS(EI)m/z 381(M $^+$); 元素分析値 $C_{18}H_{15}N_5$ O_3 Sの計算値(%) C, 56.68; H, 3.96; N, 18.36, 測定値(%) C, 56.54; H, 4.10; N, 18.14.

【0249】 [実施例57] 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-ヒドロキシフェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(2-ヒドロキシ-3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(2-ヒドロキシ-3-イオドフェニル)-1H-テトラゾールを、2等量の4-メトキシベンジル クロリド及び炭酸カリウムを用い、実施例1の工程3と同様に処理し、5-(2-ヒドロキシ-3-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾ

ールを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 3.78 (3H, s), 3.82 (3H, s), 4.89 (2H, s), 5.73 (2H, s), 6.84~6.88 (4H, m), 6.99 (1H, t), 7.32~7.34 (2H, m), 7.37~7.40 (2H, m), 7.94 (1H, dd), 8.04 (1H, dd). 【0250】 (工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)ー2ーヒドロキシフェニル)ー1Hーテトラゾールの合成5-(2ーヒドロキシー3ーイオドフェニル)ー2ー(4ーメトキシベンジル)ー2Hーテトラゾールと4ーシクロブチルー2ーエチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、引き続き、これを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 195~199℃ (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルム); IRνmax cm⁻¹ 3116, 2980, 2948, 2216, 1616, 1588, 1554, 1512; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm1.84~2.34 (6H, m), 3.63~3.72 (1H, m), 7.16 (1H, t), 7.52 (1H, s), 7.75 (1H, dd), 8.04 (1H, dd); MS (EI) m/z 323 (M⁺); 元素分析値C₁₆H₁₃N₅ OSの計算値 (%) C, 58.61; H, 4.15; N, 21.36, 測定値 (%) C, 58.69; H, 4.13; N, 21.04. 【0251】「実施例58】 5-(3-(2-(4-

【0251】 [実施例58] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-イソ プロポキシフェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-4

5- (3-イオド-2-イソプロポキシフェニル)-1 Hーテトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5- (3-イオド-2-イソプロポキシフェニル)-1-(4-メトキシベンジル)-1Hーテトラゾールを油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.0$ 5 (6H, d), 3.71 (3H, s), 4.05~4.06 (1H, m), 5.51 (2H, s), 6.68~6.71 (2H, m), 6.89~6.92 (2H, m), 6.91 (1H, t), 7.29 (1H, dd), 7.99 (1H, dd).

【0252】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-イソプロポキシフェニル)-1H-テトラゾールの合成5-(3-イオド-2-イソプロポキシフェニル)-1

- (4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾールと4 -シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の 工程4と同様に処理し、引き続き、これを実施例1の工 程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 193~196℃ (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルム-n-ヘキサン); IRνmax cm -1 3096, 2976, 2216, 1600; NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.33(6H, d), 1.92~2.45(6H, m), 3.72~3.80(1H, m), 5.10~5.18(1H, m), 7.04(1H, s), 7.28(1H, t), 7.66(1H, d), 8.37(1H, d), 13.30(1H, brs); MS(EI) m/z 365(M⁺); 元素分析値C₁₉H₁₉N₅OSの計算値(%) C, 62.44; H, 5.24; N, 19.16, 測定値(%) C, 62.45; H, 5.27; N, 19.29.

【0253】 [実施例59] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-メチ ルフェニル) -1H-テトラゾール

(工程1) 5-(3-イオド-6-メチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5- (3-イオド-6-メチルフェニル) -1 H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5- (3-イオド-6-メチルフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2 H-テトラゾールを得た。

融点 67~69℃ (再結晶溶媒:エタノールー水);
NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.
33 (6H, d), 2.56 (3H, s),
3.81 (3H, s), 5.75 (2H, s),
6.21 (2H, d), 7.04 (1H, d),
7.39 (2H, d), 7.65 (1H, d
d), 8.33 (1H, d).

【0254】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-メチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5- (3-イオド-6-メチルフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、5- (3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) -6-メチルフェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを黄色油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.9$ $0\sim2.00(1H, m), 2.00\sim2.10(1H, m), 2.30\sim2.50(4H, m), 2.65(3H, s), 3.60\sim3.80(1$ H, m), 3.81 (3H, s), 5.76 (2H, s), 6.92 (1H, s), 6.9 3 (2H, d), 7.31 (1H, d), 7.42 (2H, dd), 7.55 (1H, dd), 8.25 (1H, d).

【0255】 (工程3) 5-(3-(2-(4-)2ロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-メチルフェニル) -1 H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-メチルフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 131~132℃ (decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルム); $IRv \max cm^{-1} 1662$, 1 586, 1390, 1286, 994; NMR (40 0MHz, $DMSO-d_6$) δppm 1. $80\sim2$. 00 (1H, m), 2.00 \sim 2.10 (1H, m), $2.20\sim2.40$ (4H, m), 6 (3H, s), 3. $60\sim3$. 70 (1H, m), 7.54(1H, s), 7.56 (1H, d), 7.76 (1H, dd), 8.02 (1 H, br), 8.12 (1H, s); MS (F AB) m/z 322 (M⁺ +1); 元素分析値 C₁₇H₁₅N₅ S・H₂ Oの計算値(%) C, 52.3 8; H, 3. 97; N, 15. 42, 測定値 (%) C, 52. 42; H, 4. 04; N, 1 5. 51.

【0256】 [実施例60] 5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(2-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成 5-(2-イオドフェニル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(2-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを油状物として得た。

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 3.8$ 0 (3H, s), 5.77 (2H, s), 6. $88 \sim 6.92 (2\text{H}, d), 7.11 \sim 7.15$ $(1\text{H}, \text{m}), 7.40 \sim 7.45 (3\text{H}, \text{m}), 7.71 \sim 7.73 (1\text{H}, \text{m}), 8.0$ $0 \sim 8.02 (1\text{H}, \text{m}).$

【0257】(工程2) 5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

5-(2-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロプチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾ

リル)エチニル)フェニル)-2-(4-)トキシベンジル)-2Hーテトラゾールを褐色油状物として得た。 NMR(400MHz,CDCl $_3$) δ ppm 1.9 $1\sim2.08(2$ H,m), 2. $30\sim2.39(4$ H,m), 3. $68\sim3.73(1$ H,m), 3.77(3H,s), 5.79(2H,s), 6. $81\sim6.84(2$ H,m), 6.96(1H,s), 7. $43\sim7.52(2$ H,m), 7. $72\sim7.75(1$ H,m), 8. $13\sim8.15(1$ H,m),

【0258】 (工程3) 5-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1 H-テトラゾールの合成

5-(2-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $146\sim147$ [°]C(decomp.)(再結晶溶媒:クロロホルムーnーへキサン); $IR\nu$ max cm $^{-1}$ 2216; NMR(400MHz,DMSO-d $_6$) δ ppm 1.82 \sim 2.04(2H, m),2.18 \sim 2.46(4H, m),3.61 \sim 3.70(1H, m),7.53(1H, s),7.67 \sim 7.73(2H, m),7.88 \sim 7.91(2H, m); MS(FAB)m/z 308(M⁺+1); 元素分析値 $C_{16}H_{13}N_5$ SO 計算値(%)C,62.51; H,4.26; N,22.79,測定値(%) C,62.09; H,4.28; N,22.56.

【0259】 [実施例61] 5-(4-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(4-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成 5-(4-イオドフェニル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(4-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを油状物として得た。

融点 122~123℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n - へキサン); NMR (400MHz, CDC1 3) δ p p m 3.79 (3 H, s), 5.72 (2 H, s), 6.88~6.91 (2 H, d), 7.36~7.39 (3 H, m), 7.79~7.86 (4 H, m); MS (FAB) m/z393 (M+1); 元素分析値C₁₅H₁₃IN₄Sの計算値(%) C, 45.93; H, 3.34; N, 14.29, 測定値(%) C, 46.13; H, 3.35; N, 14.47. 【0260】(工程2) 5-(4-(2-(4-シク

ロプチルー2ーチアソリル) エチニル) フェニル) -2 - (4-メトキシベンジル) -2H-テトラソールの合 成

5-(4-イオドフェニル)-2-(4-メトキシベン ジル) -2H-テトラゾールと4-シクロプチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理 し、5-(4-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾ リル) エチニル) フェニル) -2- (4-メトキシベン ジル) -2H-テトラゾールを褐色油状物として得た。 融点 140~141℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\wedge + + \nu$); NMR (400MHz, CDC1 $_{3}$) δppm 1. 91~2. 08 (2H, m), 2. $29\sim2$. 39(4H, m), $3.65\sim3$. 74 (1H, m), 3.97 (3H, s), 5. 73 (2H, s), 6. 90 (2H, d), 6.96 (1H, s), 7.38 (2H, 7. 67 (2H, d), 8. 14 (2H, m); MS (FAB) m/z 428 (M⁺ + 1) ; 元素分析値C₂₄H₂₁N₅ OSの計算値(%) C, 67. 43; H, 4. 95; N, 16. 38, 測定值(%) C, 67. 15; H, 4. 99; N, 16. 12.

【0261】(工程3) 5-(4-(4-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1 H-テトラゾールの合成

5-(4-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $166\sim167$ [°]C(decomp.)(再結晶溶媒:クロロホルムーnーへキサン); $IRvmax cm^{-1}$ 2208; $NMR(400MHz, DMSO-d_6)\delta ppm 1.86\sim2.03(2H, m),$ $2.21\sim2.33(4H, m), 3.63\sim3.72(1H, m), 7.56(1H, s), 7.89(2H, d), 8.12(2H, d); M S(FAB) m/z 308(<math>M^+$ +1); 元素分析値 $C_{16}H_{13}N_5$ Sの計算値(%) C, 62.51; H, 4.26; N, 22.79, 測定値(%) C, 62.31; H, 4.28; N, 22.60. 【0262】 [実施例62] 5-(3-(2-(4-2))

(工程1) 5-(3-イオド-6-(N-メチル-N-トリフルオロアセチル)アミノ) ベンゾニトリルの合成

5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-(N-メチル-N-トリフルオロアセチル) アミノ) ベンゾニトリルと4-シクロプチル

-2-xチェルチアゾールを実施例1の工程4と同様に 処理し、 $5-(3-4\pi)-6-(N-x)$ チルーNート リフルオロアセチル)アミノ)ベンゾニトリルを得た。融点 $94\sim96$ $\mathbb C$ (再結晶溶媒: 94 96 $\mathbb C$ (再結晶溶媒: 94 96 $\mathbb C$ (再結晶溶媒: 94 96 $\mathbb C$ (94 96 $\mathbb C$ (94 96 100

【0263】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-(N-メチル-N-トリフルオロアセチル)アミノフェニル)-1H-テトラゾールの合成

2,6ールチジン396mg及びDMF3m1に、氷冷 撹拌下にトリフルオロ酢酸0.095m1を加えた。これを室温で30分撹拌した後、アジ化ナトリウム80m gを加え、さらに室温で1時間撹拌した。反応液に5ー (3ーイオドー6ー(NーメチルーNートリフルオロア セチル)アミノ)ベンゾニトリル320mgを加え、7 0~75℃で6時間撹拌した。冷却後、反応液を2N塩 酸50m1に注いだ。析出した結晶をろ取し、水洗後、 乾燥した。粗結晶をエーテルーnーへキサンから再結晶 し、表題物270mgを針状晶として得た。

融点 $155\sim156$ °C; IR ν max c m⁻¹ 2244, 1728, 1714; NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 1.93~2.45 (6H, m), 3.47 (3H, s), 3.70 (1H, m), 7.00 (1H, s), 7.47 (1H, d), 8.58 (1H, dd), 9.08 (1H, d); MS (FAB) m/z 433 (M+1); 元素分析值C₁₉H₁₅N₆ OS σ 計算值 (%) C,52.77; H,3.50; N,19.44, 測定值 (%) C,53.10; H,3.83; N,19.61.

【0264】 [実施例63] 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-メチルアミノフェニル) -1 H-テトラゾール:5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-(N-メチル-N-トリフルオロアセチル) アミノフェニル) -1 H-テトラゾール160mgに0.5 N炭酸ナトリウム水溶液3ml及びメタノール3mlを加え、室温で5時間撹拌した。反応液を0.5 N塩酸10mlに注ぎ、析出結晶をろ取した。粗結晶をクロロホルム-エタノールから再結晶し、表題物を針状晶として得た。

融点 $157 \sim 161$ °C; IR ν max c m⁻¹ 2216; NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3)$ δ p p m 1.92 \sim 2.45 (6H, m), 2.99 (3H, s), 3.70 (1H, m), 4.84 (1H, br), 6.72 (1H, d), 6.94 (1H, s), 8.16 (1H, br d), 8.62 (1H, br s); MS (FAB) m /z 337 $(\text{M}^+$ +1).

【0265】 [実施例64] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-トリフルオロアセトアミノフェニル) -1 Hーテトラゾール:5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-トリフルオロアセトアミノ) ベンゾニトリルを実施例62の工程2と同様に処理し、表題物を得た

融点 210~212℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー エタノール); NMR (400MHz, DMSO-d $_{6}$) δ ppm 1.85 \sim 2.40 (6H, m), 3. 70 (1H, m), 7. 14 (1H, s), 7. 76 (1H, s), 7. 78 (1H, d), 8.47 (1H, d), 8.70 (1H, d), 12.59 (1H, s); MS (FA B) m/z 418 (M⁺ +1); 元素分析値C₁₈ H₁₃F₃ N₆ OSの計算値(%) C, 51.67; H, 3.13; N, 20.09 , 測定値(%) C, 51. 51; H, 3. 33; N, 19. 97. 【0266】 [実施例65] 5-(3-(2-(4-シクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) -6-アミ ノフェニル) -1H-テトラゾール:5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -6 ートリフルオロアセトアミノフェニル) -1H-テトラ ゾールを実施例63と同様に処理し、表題物を得た。 融点 128~136℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー エタノールーnーヘキサン); $IRv \max c m^{-1} 2$ 196; NMR (400MHz, CDCl₃) δpp $m = 1.83 \sim 2.45 (6H, m), 3.83$ (1H, m), 6.72 (1H, d), 7.04 (1H, s), 7.27 (1H, m), 8.0 3 (1H, d); MS (FAB) m/z 323(M⁺ +1); 元素分析値C₁₆H₁₄N₆Sの計算値 (%) C, 59. 61; H, 4. 38; N, 2 6.07, 測定値(%) C,59.78; H, 4. 79; N, 25. 24.

【0267】 [実施例66] 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-アセトキシメチルフェニル) -1H-テトラゾール: (工程1) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2

(工程1) 5-(3-(2-(4-シクロプチルー2 ーチアゾリル) エチニル) -2-アセトキシメチルベン ゾニトリルの合成

5-(3-イオド-2-アセトキシメチル)ベンソニト

リルと4ーシクロプチルー2ーエチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、5ー(3ー(2ー(4ーシクロプチルー2ーチアゾリル)エチニル)-2ーアセトキシメチルベンゾニトリルを得た。

融点 84~87℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーnーへキサン); NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.87~2.45 (6H, m), 3.71 (1H, m), 5.49 (2H, s), 7.0 3 (1H, s), 7.49 (1H, t), 7.72 (1H, d), 7.85 (1H, d); M S (FAB) m/z 337 (M⁺+1); 元素分析値C₁₉H₁₆N₂O₂S・1/4H₂Oの計算値(%) C, 66.94; H, 4.88; N, 8.22, 測定値(%) C, 66.80; H, 4.83; N, 7.78.

【0268】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-アセトキシメチルベンゾニトリルを実施例62の工程2と同様に処理し、表題物を得た。

融点 128~136℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー エタノールーnーヘキサン); $IR \nu \max c m^{-1} 2$ 232, 1716; NMR (400MHz, CDC1 3) δ ppm 1. $76 \sim 2$. 32 (6H, m), 1. 95 (3H, s), 3. 55 (1H, m), 5.25 (1H, d), 6.88 (1H, s), 7.55 (1H, t), 7.81 (1 H, m), 7.85 (1H, m); MS (FA B) m/z 380 (M⁺ +1); 元素分析値C₁₉H 17N₅ O₂ Sの計算値(%) C, 60.19; H, 4. 52; N, 18. 46, 測定値(%) C, 6 0. 61; H, 4. 81; N, 18. 48. 【0269】 [実施例67] 5-(3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) -2-ヒド ロキシメチルフェニル) -1H-テトラゾール:5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エ チニル) -2-アセトキシメチルフェニル) -1H-テ トラゾールを実施例63と同様に処理し、表題物を得 た。

融点 $255\sim259$ °C (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノール); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ p p m 1.95 \sim 2.48 (6 H, m), 3.50 (1 H, m), 5.83 (2 H, s), 7.53 (1 H, brs), 7.67 (1 H, t), 8.04 (1 H, t), 8.17 (1 H, brs), 8.72 (1 H, d); MS (1 FAB) m/z 338 (1 M+ +1); 元素分析値1 C₁₇H₁₅N₅ OS·1/2H₂ Oの計算値(%) C, 58.94; H, 4.66; N, 20.21, 測定値(%) C, 58.72; H, 4.46; N, 20.24.

【0270】[実施例68] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-アセチル-2Hーテトラゾール:5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1Hーテトラゾール615mgに無水酢酸5ml及びピリジン1mlを加え、室温で15時間撹拌した。反応液を1N塩酸100mlに注ぎ、析出結晶をろ取、水洗後、乾燥した。粗結晶をエーテル-n-ヘキサンから再結晶し、5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-アセチル-2H-テトラゾールを得た。

融点 110~112℃; IRvmax cm⁻¹ 221 6, 1778; NMR (400MHz, DMSO-d 6) δppm 1. 90~2. 42 (6H, m), 3. 03 (3H, s), 3. $69\sim3$. 76 (1 H, m), 6.99(1H, s), 7.56 . (1H, t), 7.67 (1H, dt), 8. 30 (1H, dt), 8.52 (1H, t); MS(EI) m/z 349 (M⁺); 元素分析值C 18H₁₅N₅ OSの計算値(%) C, 61.87; H, 4.33; N, 20.04, 測定値(%) C, 6 1. 87; H, 4. 49; N, 20. 06. 【0271】[実施例69] 3-(3-(2-(4-シクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) (工程1) 3-(3-イオドフェニル)-4-(4-メトキシベンジル) - [1, 2, 4] オキサジアゾール

3-(3-4オドフェニル)-4H-[1, 2, 4]オキサジアゾールー5-オンを実施例1の工程3と同様に処理し、3-(3-4オドフェニル)-4-(4-メトキシベンジル)-[1, 2, 4]オキサジアゾール-<math>5-オンを淡黄色油状物として得た。

-5ーオンの合成

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 3.8$ 0 (3H, s), 4.74 (2H, s), 6. $84 \sim 6.86 (2H, m), 7.03 \sim 7.05$ (2H, m), 7.23 (1H, t), 7.4 1 (1H, d), 7.73 (1H, s), 7.91 (1H, d).

【0272】(工程2) 3-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(4-メトキシベンジル)-[1,2,4]オキサジアゾール-5-オンの合成

3-(3-dオドフェニル)-4-(4-メトキシベンジル)-[1,2,4]オキサジアゾールー5ーオンと4-シクロプチルー2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、<math>3-(3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(4-メトキシベンジル)-[1,2,4]オキサジアゾールー5-オンを淡黄色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.9 $0\sim2.40$ (6H, m), 3.68 ~3.79 (1 H, m), 3.76 (3H, s), 4.77 (2H, s), 6. $81\sim6$. 83 (2H,m), 7.01 (1H, s), 7.01 \sim 7.0 3 (2H, m), 7.45 (1H, d), 7. 50 (1H, t), 7.65 (1H, s), 7. 77 (1H, d). 【0273】(工程3) 3-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -4 H-[1, 2, 4] オキサジアゾール-5-オンの合成 3-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリ ル) エチニル) フェニル) -4-(4-メトキシベンジ ル) - [1, 2, 4] オキサジアゾール-5-オンを実 施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。 融点 246~249℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); IR ν max c m⁻¹ 2224, 17 82; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δp pm 1.84~2.34 (6H, m), 3.64 ~ 3.72 (1H, m), 7.57 (1H, 7. 69 (1H, t), 7. 91 (1H, d), 7.92 (1H, d), 8.07 (1 H, s), 13.01(1H, s); MS (E I) m/z 323 (M⁺); 元素分析値C₁₇H₁₃N 3 O₂ Sの計算値(%) C, 63.14; H, 4.0 5; N, 12.99, 測定値(%) C, 62.7 4; H, 4. 07; N, 12. 61.

【0274】 [実施例70] (2) -5-(3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) ベンジリデン) -2-チオキソチアゾリジン-4-オン: (工程1) 3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) ベンズアルデヒドの合成 3-イオドベンズアルデヒドルと4-シクロプチルー2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) ベンズアルデヒドを得た。

融点77~79℃; NMR(400MHz, CDC13) δ p p m 1.89~2.43(6H, m), 3.67~3.75(1H, m), 6.99(1H, s), 7.56(1H, t), 7.83(1H, dt), 7.91(1H, dt), 8.09(1H, t), 10.02(1H, s).
【0275】(工程2) (2) −5−(3−(2−(4−シクロブチルー2−チアゾリル)エチニル)ベンジリデン)−2−チオキソチアゾリジン−4−オンの合成

3- (2- (4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) ペンズアルデヒド535mg、ロダニン266mg及び酢酸ナトリウム656mgに酢酸20mlを加え、4時間加熱還流した。冷却後、反応液を水200m

1に注ぎ、析出した結晶を集めた。これを、シリカゲルを用いるアカラムクロマトグラフィー(溶出液:クロロホルム:酢酸エチル=20:1)にて精製し、クロロホルム-n-ヘキサンから再結晶し、表題物を淡黄色結晶性粉末として得た。

融点 $198\sim201$ ℃; $IRvmax cm^{-1} 220$ 8, 1732; $NMR (400MHz, CDCl_3)$ $\delta ppm 1. <math>91\sim2$. 41 (6H, m), 3. 69 ~3 . 77 (1H, m), 7. 00 (1H, s), $7. 49\sim7$. 51 (2H, m), 7. 63 (1H, s), $7. 64\sim7$. 67 (1H, m), 7. 69 (1H, s), 9. 77 (1H, s); $MS (EI) m/z 382 (M^+)$; 元素分析值 $C_{19}H_{14}N_2$ OS_3 の計算値 (%) C, 59. 66; H, 3. 69; N, 7. 32, 測定値 (%) C, 59. 52; H, 3. 66; N, 7. 22.

【0276】 [実施例71] 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) - [1, 2, 4] オキサジアゾリン-3-オン: (工程1) 5-(3-イオドフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) - [1, 2, 4] オキサジアゾリン-3-オンの合成 5-(3-イオドフェニル) - [1, 2, 4] オキサジアゾリン-3-オンを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(3-イオドフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) - [1, 2, 4] オキサジアゾリン-3-オ

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 3.8 0 (3H, s), 5.32 (2H, s), 6. 92 (2H, d), 7.42 (1H, d), 7.85 (1H, d), 7.94 (1H, t), 8.06 (1H, d), 8.43 (1H, s). 【0277】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2 -(4-メトキシベンジル)-[1, 2, 4]オキサジアゾリン-3-オンの合成

ンを赤褐色油状物として得た。

5-(3-dx)ドフェニル) -2-(4-x)トキシベンジル) -[1,2,4] オキサジアゾリン-3-dxと4-シクロプチル-2-xチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、5-(3-(2-(4-シ)2-(4-x)) エチニル)フェニル) -2-(4-x) キシベンジル) -[1,2,4] オキサジアゾリン-3-dxを赤褐色油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.9$ $0\sim 2.00 (1H, m), 2.00\sim 2.10 (1H, m), 2.20\sim 2.40 (4H, m), 3.60\sim 3.80 (1H, m), 3.82 (3H, s), 5.34 (2H, s), 6.92 (2H, d), 6.99 (1H, s), 7.4$ 4 (2H, d), 7.53 (1H, t), 7.78 (1H, d), 8.09 (1H, d), 8.30 (1H, s).

【0278】(工程3) 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-[1,2,4]オキサジアゾリン-3-オンの合成5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-[1,2,4]オキサジアゾリン-3-オンを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。 融点 208~212℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー メタノール-n - \wedge + サン); IR ν max c m⁻¹ 1 600, 1470, 1380, 1248, 1136; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1. $80 \sim 1$. 90 (1H, m), 1. $90 \sim 2$. 10 (1H, m), 2.20 \sim 2.40 (4H, m), 3.60 \sim 3.80(1H, m), 7.5 5 (1H, s), 7.61 (1H, t), 7.8 8 (1H, d), 8.03 (1H, d), 8. 25 (1H, s), 10.66 (1H, bг s); MS (FAB) m/z 324 (M^+ +1); 元素分析値C₁₇H₁₃N₃O₂S・0.475H₂Oの 計算值(%) C, 61.51; H, 4.24; N, 12.66, 測定値(%) C, 61.92; H, 4. 64; N, 12. 50.

【0279】 [実施例72] 3-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -5-ヒドロキシイソオキサゾール:3-(3-イオドフェニル) -5-ヒドロキシイソオキサゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $143\sim148$ C (再結晶溶媒:クロロホルムー $n- \wedge + \psi \nu$); NMR (400MHz, CDC 1_3) δ p p m 1.90 \sim 2.00(1H, m), 2.00 \sim 2.10(1H, m), 2.20 \sim 2.40(4H, m), 3.60 \sim 3.80(1H, m), 4.20(2H, ds), 6.99(1H, s), 7.54(1H, t), 7.56(1H, d), 7.63(1H, s), 7.66(1H, d); MS (FAB) m/z 323(M $^+$ +1).

【0280】 [実施例73] 2-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -[1,3,4] オキサジアゾリン-5-オン:2-(3-イオドフェニル) -[1,3,4] オキサジアゾリン-5-オンと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、表題物を得た。

融点186~190℃; NMR (400MHz, DM SO-d₆) δppm1.90~2.00 (1H, m), $2.00\sim2.10$ (1 H, m), $2.20\sim2.50$ (4 H, m), $3.60\sim3.80$ (1 H, m), 7.00 (1 H, s), 7.50 (1 H, t), 7.71 (1 H, d), 7.85 (1 H, d), 8.08 (1 H, s); MS (FAB) m/z 324 (M⁺ +1); 元素分析 位C₁₇H₁₃N₃ O₂ S·0.3H₂Oの計算値 (%) C, 63.44; H, 4.02; N, 12.33, 測定値 (%) C, 63.15; H, 4.24; N, 12.34.

【0281】 [実施例74] 2-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -[1, 2, 4] オキサジアゾリジン-3, 5-ジオン: 2-(3-(オドフェニル)-[1, 2, 4] オキサジアゾリジン-3, 5-ジオンと4-シクロブチルー2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $141 \sim 145$ $^{\circ}$ $^{\circ}$

【0282】 [実施例75] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンジリデン) チアゾリジン-2, 4-ジオン:3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンズアルデヒドと2, 4-チアゾリンジオンを実施例70と同様に処理し、表題物を得た。

融点 198~201℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); IRνmax cm⁻¹ 2212, 1748; NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.89~2.44(6H, m), 3.69~3.77(1H, m), 7.00(1H, s), 7.47~7.53(2H, m), 7.63~7.65(1H, m), 7.73(1H, s), 7.83(1H, s), 9.09(1H, s); MS(EI) m/z 366(M⁺);元素分析値C₁₉H₁₉N₂O₂S₂2·1/4H₂Oの計算値(%) C, 61.52; H, 3.94; N, 7.55, 測定値(%) C, 61.51; H, 3.89; N, 7.31.

【0283】 [実施例76] 1-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4H-テトラゾリン-5-オン:

(工程1) 1-(3-イオドフェニル)-4-(2-

(トリメチルシリル) エトキシ) メチルー4H-テトラ ゾリン-5-オンの合成

1-(3-イオドフェニル)-4H-テトラゾリン-5-オン202mg、炭酸カリウム152mgにDMF5mlを加え、0℃デ撹拌下に、(2-クロロメトキシエチル)トリメチルシラン133mgを加えた。同温度で30分、さらに室温で2時間撹拌した。反応液を水100mlに注ぎ、酢酸エチルで抽出した。抽出液を、飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得っられる残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:クロロホルム:n-ヘキサン=1:1)で精製し、1-(3-イオドフェニル)-4-(2-(トリメチルシリル)エトキシ)メチルー4H-テトラゾリン-5-オンを油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 0.0$ 3 (9H, s), 0.99 (2H, t), 3.75 (2H, t), 5.39 (2H, s),7.24 $(1H, t), 7.70 \sim 7.73 (1H, m), 7.97 \sim 7.99 (1H, m),$ 8.35 (1H, s).

【0284】 (工程2) 1- (3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4 H-テトラゾリン-5-オンの合成

1-(3-イオドフェニル)-4-(2-(トリメチルシリル)エトキシ)メチル-4H-テトラゾリン-5-オンと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、引き続きこれにDMF3ml、テトラブチルアンモニウム フルオリド(1.0MのTHF溶液)1mlを加え、60℃で2時間撹拌した。反応液を1N塩酸100mlに注ぎ、析出結晶をろ取した。粗結晶をクロロホルム-n-ヘキサンから再結晶し、表題物を淡褐色結晶性粉末として得た。

融点 $196\sim199$ ℃; $IRvmax cm^{-1} 221$ 2, 1742; $NMR (400MHz, DMSO-d_6) \delta ppm 1.91\sim2.46 (6H, m), 3.71\sim3.80 (1H, m), 7.01 (1H, s), 7.52 (1H, t), 7.59 (1H, d), 8.33 (1H, s); <math>MS (FAB) m/z 323 (M^+ +1)$; 元素分析値 $C_{16}H_{13}N_5 OS の計算値 (%) C, 59.43; H, 4.05; N, 21.66, 測定値 (%) C, 59.06; H, 4.09; N, 21.33.$

【0285】 [実施例77] 4-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1 or 2 or 3H-[1, 2, 3] -トリアゾール:

(工程1) エチル 4-(3-プロモフェニル)-1H-[1, 2, 3]-トリアゾール-5-カルボキシレートの合成

アジ化ナトリウム1. 11gをDMF10mlに懸濁し、氷冷撹拌下に、塩化アルミニウム1. 45を徐々に加えた。反応液を室温で1時間撹拌した後、プロピオル酸エチル エステル1. 3gのDMF5ml溶液を5分をかけて滴下した。反応液を室温で1時間撹拌した後、さらに60℃で30分撹拌した。冷却後、反応液を、氷100ml及び2M塩酸50ml中に注いだ。析出した結晶をろ取し、風乾した。粗結晶をクロロホルムに溶解し、シリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:クロロホルム:エタノール=8:2)で精製し、4-(3-ブロモフェニル)-1H-[1,2,3]-トリアゾール1.52gを得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.3 9 (3H, t), 4.44 (2H, q), 7. 34 (1H, t), 7.58 (1H, m), 7.84 (1H, d), 8.05 (1H, brs).

【0286】(工程2) エチル 4-(3-プロモフェニル)-1-(4-メトキシベンジル)-1H[1, 2, 3]-トリアゾール-5-カルボキシレート、エチル4-(3-プロモフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-[1, 2, 3]-トリアゾール-5-カルボキシレート及び エチル 4-(3-プロモフェニル)-3-(4-メトキシベンジル)-3H-[1, 2, 3]-トリアゾール-5-カルボキシレートの合成

エチル 4-(3-プロモフェニル)-1H-[1,2,3]-トリアゾール-5-カルボキシレートを実施例1の工程3と同様に処理し、エチル <math>4-(3-プロモフェニル)-1H-[1,2,3]-トリアゾール-5-カルボキシレート、エチル <math>4-(3-プロモフェニル)-2-(4-J)トキシベンジル)-2H-[1,2,3]-トリアゾール-5-カルボキシレート及び エチル <math>4-(3-7DE-J)ルボキシレート及び エチル 4-(3-7DE-J)ルボキシレート及び エチル 4-(3-7DE-J)ルボキシレート及び エチル 4-(3-7DE-J)ルボキシレート及び エチル 4-(3-7DE-J)ルボキシレートをび エチル 4-(3-7DE-J)ルボキシレートをが エチル 4-(3-7DE-J)ルボキシレートを1位、2位及び3位の混合物として得た。

NMR $(400MHz, CDC1_3) \delta ppm 1.2$ $4\sim1.34 (3H, m), 3.78 (3H, s), 4.25\sim4.45 (2H, m), 5.5$ $9\sim5.87 (2H, series of s),$ $6.83\sim7.97 (8H, m).$

工程3のプロミドを実施例19の工程2と同様に処理

し、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶 出液:n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製し、 1位、2位或いは3位の単一異性体で、ハロゲン交換と 同時に、脱エステルした、4-(3-イオドフェニル) -1H-(4-メトキシベンジル)-1H-[1, 2,3] ートリアゾール、または 4-(3-イオドフェニ (μ) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-[1,2, 3] ートリアゾール、または 4-(3-イオドフ ェニル) -3- (4-メトキシベンジル) -3H-[1, 2, 3] -トリアゾールを油状物をとして得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 3.8 s), 5.51(2H, s), 6. 93 (2H, d), 7.13 (1H, t), 7. 27 (2H, d), 7. 60 (1H, m), 7. 70 (1H, d), 8. 12 (1H, m). 【0288】 (工程4) 4-(3-(2-(4-シク ロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -1 or 2 or 3-(4-メトキシベンジル)-1 H- [1, 2, 3] -トリアゾールの合成 工程3で得たイオド体と4-シクロブチルー2-エチニ ルチアゾールを、実施例1の工程4と同様に処理し、4 - (3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル)フェニル) -1-(4-メトキシベンジル) -1H-[1, 2, 3] -トリアゾール、または 4-(3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル)エ チニル)フェニル) -2-(4-メトキシベンジル)-2H-[1, 2, 3] -トリアゾール、または 4-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エ チニル)フェニル) -3-(4-メトキシベンジル) -3H-[1, 2, 3] -トリアゾールを油状物として得 NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.8

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.8 $5\sim2$. 43 (6H, m), 3.69 (1H, m), 3.83 (3H, s), 5.52 (2H, s), 6.94 (2H, d), 6.96 (1H, s), 7.28 (2H, d), 7.42 (1H, t), 7.53 (1H, m), 7.63 (1H, s), 7.88 (1H, m), 7.95 (1H, t).

【0289】(工程5) 4-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1 H-[1,2,3]-トリアゾールの合成 上記の工程3で得られた化合物を、実施例1の工程5と

上記の工程3で得られた化合物を、実施例1の工程5と 同様に処理し、表題物を得た。

融点 146~150℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); IRνmax cm⁻¹ 2216; N MR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.85 ~2.45 (6H, m), 3.71 (1H, m), 6.97 (1H, s), 7.47 (1H, t), 7.59 (1H, d), 7.87 (1 H, d), 7.79(1H, s), 8.05 (1H, br); MS(EI) m/z 306 (M⁺); 元素分析値C₁₇H₁₄N₄S・1/5H₂Oの計算値(%) C, 65.68; H, 4.70; N, 18.02, 測定値(%) C, 65.83; H, 4.67; N, 17.55.

【0290】 [実施例78] エチル 4-(3-(2-(4-2)) エチル 2-(4-2) エチル

(工程1) エチル 3-(2-(4-シクロプチルー 2-チアゾリル) エチニル) フェニルプロピオル酸の合 ^成

エチル 3ーイオドフェニルプロピオル酸と4ーシクロプチルー2ーエチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、エチル 3ー(2-(4-シクロプチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニルプロピオル酸を赤褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.3 7 (3H, t), 1.85~2.45 (6H, m), 3.70 (1H, m), 4.31 (2H, q), 6.98 (1H, s), 7.38 (1H, t), 7.59 (1H, d), 7.65 (1H, d), 7.79 (1H, s). 【0291】(工程2) エチル 4-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1H-[1, 2, 3]-トリアゾール-5-カルボキシレートの合成

エチル 3-(2-(4-シクロプチル-2-チアソリル) エチニル) フェニルプロピオル酸を実施例77の工程1と同様に処理し、表題物を得た。

融点 142~145℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n- へキサン); IR ν max cm^{-1} 2216, 17 12; NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1. 37 (3H, t), 1. $85\sim2$. 45 (6 H, m), 3.73 (1H, m), 4.42 (2H, q), 6.99(1H, s), 7.4 5 (1H, t), 7.62 (1H, d), 7. 89 (1H, d), 7.99 (1H, s); MS (EI) m/z 378 (M⁺);元素分析値C₂₀H₁₈ N₄ O₂ Sの計算値(%) C, 63.47; H, 4.79; N, 14.81, 測定値(%) C, 6 3. 37; H, 4. 90; N, 14. 55. 【0292】 [実施例79] 4-(3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-[1, 2, 3]-トリアゾール-5-カルボン 酸: xチル 4-(3-(2-(4-)シュアナル-2)ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-[1, 2, 3] ートリアゾールー5-カルボキシレートを実施

例56と同様に処理し、表題物を得た。

融点 142~145℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノール); IR ν max c m ⁻¹ 2216, 1740; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ p p m 1.85~2.40 (6H, m), 3.68 (1H, m), 7.32 (1H, s), 7.54 (1H, t), 7.65 (1H, m), 7.95 (1H, br), 8.09 (1H, br); MS (EI) m/z 350 (M⁺); 元素分析値C 18H₁₄N₄O₂ Sの計算値 (%) C, 61.70; H, 4.03; N, 15.99, 測定値 (%) C, 61.84; H, 4.27; N, 15.71.【0293】 [実施例80] 4-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1ーメチルー1H-[1,2,3]-トリアゾールー5ーカルボン酸:

(工程1) エチル 4-(3-(2-(4-シクロブ チルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1-メ チルー1H-[1, 2, 3] -トリアゾール-5-カルボキシレート、及び エチル <math>4-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メチル-2H-[1, 2, 3] -トリアゾール-5-カルボキシレートの合成

エチル $4-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアソリル) エチニル) フェニル) -1H-[1, 2, 3] -トリアゾール-5-カルボキシレートを実施例1 の工程3の4-メトキシベンジル クロリドの替わりに、ヨウ化メチルを用い、同様に処理し、1位:2位与1:1の混合物としてエチル <math>4-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアソリル) エチニル) フェニル) -1-メチルー1H-[1, 2, 3] -トリアゾールー5-カルボキシレート、及び エチル4-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアソリル) エチニル) フェニル) -2-メチル-2H-[1, 2, 3] -トリアゾールー5-カルボキシレートを油状物として得た。NMR <math>(400MHz, CDC1_3) \delta ppm$ 1.3

2 and 1. 39 (3H, each t),
1. 85~2. 45 (6H, m), 3. 70 (1
H, m), 4. 31 and 4. 36 (3H,
each s), 4. 37 ans 4. 43 (2
H, each q), 6. 96 (1H, s),
7. 46 (1H, t), 7. 64 (1H, br
d), 7. 78 and 7. 88 (1H, each
br d), 7. 97 and 8. 07 (1H,
each br s).

上記、1-メチル体、及び2-メチル体の混合物を、実施例56と同様に処理し、クロロホルム-n-ヘキサン

から再結晶し、表題物を得た。

融点 $142\sim145$ °C; IR ν max c m⁻¹ 2216; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ p p m 1.82 \sim 2.35(6H, m), 3.68 (1H, m), 4.18(3H, s), 7.49(1H, t), 7.53(1H, s), 7.62(1H, d), 8.13(1H, d), 8.44(1H, s); MS (EI) m/z 364(M⁺).

【0295】[実施例81] 4-(3-(2-(4-シクロプチルー2ーチアソリル) エチニル) フェニル) -2-メチル-2H-[1, 2, 3]-トリアゾール-5-カルボン酸: 4-(3-(2-(4-シクロプチル -2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メチル -2H-[1, 2, 3]-hyry-n-5-nux+シレートを実施例56と同様に処理し、表題物を得た。 融点 142~145°C; IR v max c m⁻¹ 221 6; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δpp $m 1.82\sim2.35(6H, m), 3.67$ (1H, m), 4.10 (3H, s), 7.4 8 (1H, t), 7.53 (1H, s), 7. 5 d), 8.17(1H, d), 8.3 7 (1H, 7 (1H, s); MS (EI) m/z 364 (M ⁺).

【0296】 [実施例82] 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1-(2-メトキシエトキシ) メチル-1H-[1,2,3]-トリアゾール-4-カルボン酸:

(工程1) エチル 5-(3-イオドフェニル)-1-(2-メトキシエトキシ)メチル-1H-[1, 2, 3]-トリアゾール-4-カルボキシレート、エチル5-(3-イオドフェニル)-2-(2-メトキシエトキシ)メチル-2H-[1, 2, 3]-トリアゾール-4-カルボキシレート、及び エチル5-(3-イオドフェニル)-3-(2-メトキシエトキシ)メチル-3H-[1, 2, 3]-トリアゾール-4-カルボキシレートの合成

エチル 5-(3-イオドフェニル)-1H-[1,2,3]-トリアゾールー4ーカルボキシレートを実施例1の工程3の4ーメトキシベンジル クロリドの替わりに、<math>2-(2-メトキシエトキシ)メチル クロリドを用い、同様に処理し、1、2、及び3位の混合物のエチル 5-(3-イオドフェニル)-1-(2-メトキシエトキシ)メチルー1H-[1,2,3]-トリアゾールー4-カルボキシレート、エチル <math>5-(3-イオドフェニル)-2-(2-メトキシエトキシ)メチルー2H-[1,2,3]-トリアゾールー4-カルボキシレート、及び エチル <math>5-(3-イオドフェニル)-3-(2-メトキシエトキシ)メチルー3-(2-メトキシエトキシ)メチルー $3-(2-\lambda+2)$ メチルー $3-(2-\lambda+2)$ メチルー $3-(2-\lambda+2)$

物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.2 5~1.42 (3H, m), 3.25~3.40 (3 H, series of s), 3.36 (1H, s), 3.54 (2H, m), 3.49~3.85 (4H, m), 4.30~4.48 (2H, m), 5.80~6.12 (3H, series of s), 7.15~8.23 (4H, m). 【0297】(工程2) エチル 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル) -1-(2-メトキシエトキシ)メチルー1H-[1,2,3]-トリアゾールー4-カルボキシレートの合成

上記工程1で得られた、イオド体と4ーシクロプチルー2ーエチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、生成物をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:nーヘキサンー酢酸エチル=4:1)で分離し、エチル 5ー(3ー(2ー(4ーシクロプチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニル)ー1ー(2ーメトキシエトキシ)メチルー1Hー[1,2,3]ートリアゾールー4ーカルボキシレートを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.3 1 (3H, t), 1.88~2.43 (6H, 3. 36 (3H, s), 3. 54 (2H, m), 3.68 (1H, m), 3.82 (2 H, m), 4.35 (2H, q), 5.70 (2H, s), 6.97 (1H, s), 7.52 7. 57 (1H, m), t), (1 H,4 (1H, m), 7.76 (1H, m). 【0298】(工程3) 5-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -1 - (2-メトキシエトキシ) メチル-1H-[1, 2, 3] ートリアゾールー4ーカルボン酸の合成 エチル 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チ アゾリル) エチニル) フェニル) -1-(2-メトキシ エトキシ) メチルー1 H-[1, 2, 3] -トリアゾー ルー4-カルボキシレートを実施例56と同様に処理

融点 143~146℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー
n-ヘキサン); NMR (400MHz, DMSOd₆) δppm 1.82~2.38 (6H, m),
3.23 (3H, s), 3.43 (2H, m),
3.64 (3H, m), 5.61 (2H,
s), 7.41 (1H, s), 7.59 (1H,
t), 7.67 (1H, br d), 7.75
(1H, br d), 7.84 (1H, br
s); MS (EI) m/z 439 (M⁺ +1).
【0299】 [実施例83】 5-(2-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェ

し、表題物を得た。

ニル) -4-チアゾリル) -1H-テトラゾール:
(工程1) 5-(2-(3-イオドフェニル) -4チアゾリル) -2-(4-メトキシベンジル) -2Hテトラゾールの合成
5-(2-(3-イオドフェニル) -4-チアゾリル)
-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(2-(3-イオドフェニル) -4-チアゾリル)
ル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを得た。

融点 173~176℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 3) δ p p m 3.76 (3 H, s), 6.13 (2 H, s), 6.84~6.87 (2 H, m), 7,25 (1 H, t), 7.31~7.34 (2 H, m), 7.84 (1 H, d), 7.93 (1 H, d), 8.32 (1 H, s), 8.3 5 (1 H, s); MS (EI) m/z 475 (M⁺+1); 元素分析値C₁₈H₁₄IN₄OSの計算値 (%) C,45.49; H,2.97; N,14.73, 測定値 (%) C,45.46; H,3.06; N,14.74.

【0300】(工程2) 5-(2-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-チアゾリル)-1H-テトラゾールの合成5-(2-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-チアゾリル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、引き続き、実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $156\sim159$ C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルム); $IRvmax cm^{-1} 2216$; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δ ppm $1.88\sim2.33$ (6H, m), $3.65\sim3.73$ (1H, m), 7.57 (1H, s), 7.69 (1H, t), 7.84 (1H, d), 8.17 (1H, d), 8.39 (1H, s), 8.66 (1H, s); MS (FAB) m/z 391 (M^++1); 元素分析値 $C_{19}H_{14}N_6$ S2 の計算値(%) C, 58.44; H, 3.6 1; N, 21.52, 測定値(%) C, 58.6 0; H, 3.34; N, 21.55. 【0301】[実施例84] 3-(3-(2-(4-2)))

 (工程1) 3-(3-(2-(4-シクロプチル-2 ーチアゾリル) エチニル) -1-プロモベンゼンの合成 4-シクロプチル-2-エチニルチアゾールと1-プロモー3-イオドベンゼンを実施例1の工程4と同様に処理し、3-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チア ゾリル) エチニル) -1-プロモベンゼンを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.8 $5\sim2$. 45 (6H, m), 3.70 (1H, m), 6.97 (1H, s), 7.24 (1H, t), 7.52 (1H, m), 7.74 (1H, s).

【0302】(工程2) 3-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)ベンズアルデヒドの合成

3- (3- (2- (4-シクロプチルー2-チアソリル) エチニル) -1-プロモベンゼン600mg、3-ホルミルフェニルボロニック アシド232mg、及びテトラキス(トリフェニルフォスフィン) [0] パラジウム109mgに2Mcm-1炭酸ナトリウム水溶液3.5m1及び1,2-ジメトキシエタン25m1を加え、2時間加熱還流した。冷却後、水100mを加え。塩化メチレン抽出した。抽出層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残渣を、シリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサン-酢酸エチル=3:1)で分離し3-(3-(2-(4-シクロプチルー2-チアソリル)エチニル)フェニル)ベンズアルデヒド325mgを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.8 5~2.45 (6H, m), 3.71 (1H, m), 6.97 (1H, s), 7.49 (1H, t), 7.58~7.67 (3H, m), 7. 84~7.92 (3H, m), 8.12 (1H, t), 10.11 (1H, s).

【0303】(工程3) 3-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)ベン ゾニトリルの合成

3-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) ベンズアルデヒド300mg、ヒドロキシルアミン塩酸塩65mg、及びギ酸ナトリウム119mgにギ酸5mlを加え、2時間加熱還流した。冷却後、反応液に水50mlを加え、塩化メチレンで抽出した。抽出層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:nーペキサンー酢酸エチル=9:1) で分離し3-(3-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) ベンゾニトリル280mgを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.8 7~2.45 (6H, m), 3.71 (1H, m), 6.98 (1H, s), 7.48 (1H, t), 7.54~7.94 (7H, m). 【0304】(工程4) 3-(3-(2-(4-シク ロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) 安息 香酸の合成

3-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) ベンゾニトリル250mgに4N水酸化ナトリウム水溶液5ml及びエタノール10mlを加え、5時間加熱還流した。冷却後反応液を1N塩酸50mlに注ぎ、析出した結晶をろ取、水洗後、乾燥した。粗結晶をクロロホルムーエタノールから再結晶し、表題物を微細プリズム晶として得た。

融点 119~120℃; IR v max c m ⁻¹ 2216, 1694; NMR (400MH z, CDCl₃) δppm 1.85~2.45 (6H, m), 3.71 (1H, m), 6.97 (1H, s), 7.45~8.14 (7H, m), 8.35 (1H, brs); MS (EI) m/z 359 (M ⁺); 元素分析値C₂₂H₁₇N₂ Sの計算値 (%) C, 73.51; H, 4.77; N, 3.90, 測定値 (%) C, 73.80; H, 5.00; N, 3.52.【0305】[実施例85] 5-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-エチルイソオキサゾールー4ーカルボン酸:

(工程1) 5-(3-イオドフェニル)-3-エチルイソオキサゾールー4ーカルボキシレートの合成エチル 3-イオドプロピオル酸750mg、4-クロロフェニルイソシアン酸1.19g、1-ニトロプロパン334mg、及びトリエチルアミンン0.087mlにベンゼン30mlを加え、2日間撹拌した。不容物をろ別し、ろ液を留去した。残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサン一酢酸エチル=10:1)で分離し5-(3-イオドフェニル)-3-エチルイソキサゾールー4ーカルボキシレート856mgを淡黄色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 1. 3 3 (3H, t), 1. 34 (3H, t), 2. 97 (2H, q), 4. 31 (2H, q), 7. 22 (1H, m), 7. 83 (2H, m), 8. 22 (1H, d).

【0306】(工程2) エチル 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-エチルイソオキサゾール-4-カルボキシレートの合成

5- (3-イオドフェニル) -3-エチルイソオキサゾ -ルー4-カルボキシレートと4-シクロプチルー2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理 し、エチル 5- (3- (2- (4-シクロプチルー2 -チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-エチルイソ オキサゾールー4-カルボキシレートを油状物として得 た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.3$ 3 (3H, t), 1.36 (3H, t), 1.

85~2.45(6H, m), 2.98(2H, q), 3.70(1H, m), 4.33(2H, q), 6.97(1H, s), 7.49(1H, t), 7.72(1H, d), 7.89(1H, d), 8.10(1H, s).

【0307】(工程3) 5-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3ーエチルイソオキサゾールー4ーカルボン酸の合成エチル 5-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3ーエチルイソオキサゾールー4ーカルボキシレートを実施例56と同様に処理し、表題物を得た。

融点 149~150℃ (再結晶溶媒:エーテル);
IRνmax cm⁻¹ 2224, 1710; NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.37 (3H, t), 1.85~2.43 (6H, m), 3.01 (2H, q), 3.71 (1H, m), 5.70 (1H, br), 6.98 (1H, s), 7.47 (1H, t), 7.67 (1H, d), 7.92 (1H, d), 8.08 (1H, s); MS (EI) m/z 378 (M⁺); 元素分析値C₂₁H₁₈N₂O₃ S·1/2H₂Oの計算値 (%) C,65.10; H,4.94; N,7.23, 測定値 (%) C,65.16; H,4.78; N,7.08.

【0308】 [実施例86] N-(1H-テトラゾール-5-イル)-5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル)-3-エチルイソオキサゾール-4-カルボキサミド:5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル)フェニル)-3-エチルイソオキサゾール-4-カルボン酸300mg、5-アミノー1H-テトラゾール85mg、及び1,1'-カルボニルジイミダゾール174mgにDMF5mlを加え80~85℃で5時間撹拌した。冷却後、反応液を水100mlに注ぎ、析出した結晶をろ取した。粗結晶をクロロホルムーエタノールから再結晶し、表題物を得た。

融点 $265\sim268$ °C; IRνmax cm⁻¹ 222 0, 1682; NMR (400MHz, DMSO-d $_{6}$) δ ppm 1. 25 (3H, t), 1. $85\sim$ 2. 35 (6H, m), 2. 85 (2H, q), 3. 67 (1H, m), 7. 56 (1H, s), 7. 64 (1H, t), 7. 86 (2H, d), 8. 04 (1H, s), 12. 61 (1H, br); MS (EI) m/z 445 (M⁺); 元素分析值 $C_{22}H_{19}N_7$ O_2 Sの計算値(%) C, 59. 31; H, 4. 30; N, 22. 01, 測定値(%) C, 59. 16; H, 4. 30; N, 21. 83.

【0309】 [実施例87] 1-(3-(2-(4-

シクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -3-メチル-5-(1H-テトラゾール-5-イル) -2, 4-(1H, 3H) -ピリミジンジオン: 1-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エ **チニル**) フェニル) -3-メチル-5- (2-(4-メ トキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2, 4-(1H, 3H) - ピリミジンジオンを実施例1 の工程5と同様に処理し、表題物を得た。 融点 256~259℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー エタノールーnーヘキサン); $IRv \max c m^{-1} 1$ 722, 1658; NMR (400MHz, DMSO $-d_6$) δppm 1. 86~2. 02 (2H, m), 2.20 \sim 2.31(4H, m), 3.3 5 (3H, s), 3. $63\sim3$. 71 (1H, m), 7.54 (1H, s), 7.62 \sim 7.6 9 (2H, m), 7.77 (1H, d), 7. 87 (1H, s), 8.64 (1H, s); MS (EI) m/z 431 (M +); 元素分析値C₂₁H ₁₇N₇O₂ Sの計算値(%) C, 58.45; H, 3.97; N, 22.73, 測定値(%) C, 5 8. 19; H, 4. 03; N, 22. 62. 【0310】 [実施例88] エチル 1-(3-(2 - (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フ ェニル) -5- (1H-テトラゾール-5-イル) -2, 4-ジオキソー3-(1H, 3H) ーピリミジンア セート: (工程1) エチル 1-(3-イオドフェニル)-5 - (2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾー $\nu - 5 - 4\nu$) - 2, 4 - 5 + 2 - 3 - (1 H, 3)H) ーピリミジンアセートの合成 エチル 1-(3-イオドフェニル)-5-(1H-テ トラゾール-5 - イル) -2, 4 - ジオキソ-3 - (1) H, 3H) ーピリミジンアセートを実施例1の工程3と 同様に処理し、エチル 1-(3-イオドフェニル)-5-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾ $-\mu - 5 - 4\mu$) -2, 4 - 3 + 2 - 3 - 4 + 3 - 4 - 4 + 3 - 4 - 4 + 3H) ーピリミジンアセートをアモルファスとして得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.2 9 (3H, t), 3.78 (3H, s), 4. 23 (2H, q), 4.81 (2H, s), 5. 75 (2H, s), 6. $87\sim6$. 89 (2 H, m), 7.24 (1H, t), 7.36 \sim 7..38 (2H. m), 7.40 (1H, d), 7. 77 (1H, s), 7.81 (1H, d), 8.30 (1H, s). 【0311】(工程2) エチル 1-(3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) フェ ニル) -5-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールー5ーイル) -2、4ージオキソー3ー

(1H, 3H) ーピリミジンアセートの合成

エチル 1-(3-イオドフェニル)-5-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2,4-ジオキソー3-(1H,3H)-ピリミジンアセートと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、エチル <math>1-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-5-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2,4-ジオキソー3-(1H,3H)-ピリミジンアセートをアモルファスとして得た。

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3)$ $\delta \text{ ppm}$ 1. 3 4 (3H, t), 1. $91 \sim 2.08 \text{ (2H, m)}$, 2. $28 \sim 2.39 \text{ (4H, m)}$, 3. 6 $5 \sim 3.74 \text{ (1H, m)}$, 3. 78 (3H, s), 4. 30 (2H, q), 4. 81 (2H, s), 5. 70 (2H, s), 6. $86 \sim 6.88 \text{ (2H, m)}$, 6. 99 (1H, s), 7. $16 \sim 7.18 \text{ (2H, m)}$, 7. 29 (1H, d), 7. 45 (1H, s), 7. 49 (1H, t), 7. $64 \sim 7.67 \text{ (1H, m)}$, 7. 67 (1H, s).

【0312】(工程3) エチル 1-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-5-(1H-テトラゾール-5-イル)-2,4-ジオキソ-3-(1H,3H)-ピリミジンアセートの合成

エチル 1-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアソリル) エチニル) フェニル) <math>-5-(2-(4-メトキンベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2, 4-ジオキソ-3-(1H, 3H) -ピリミジンアセートを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 247~249℃ (decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルム-n-ヘキサン); IRvmax cm ⁻¹ 2216, 1752, 1720, 1656, 160 2; NMR (400MHz, DMSO-d6) δpp m 1. 22 (3H, t), 2. $18\sim2$. 32 (4 H, m), $3.63 \sim 3.71 \text{ (WH)}$ m), 4.18 (2H, q), 4.74 (2H, 7.55 (1H, s), 7.65(1 H, t), 7. 71 (1H, d), 7. 79 (1 H, d), 7.92 (1H, d), 8.75 (1H, s); MS (EI) m/z 503 (M⁺); 元素分析値C₂₄H₂₁N₇O₄S・1/4H ₂ Oの計算値(%) C, 56.74; H, 4.2 7; N, 19.30, 測定値(%) C, 56.5 4; H, 4. 28; N, 19. 12. 【0313】[実施例89] 1-(3-(2-(4-シクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル)

-3-メチル-5-(1H-テトラゾール-5-イル)

-2, 4-ジオキソ-3-(1H, 3H)-ピリミジン 酢酸:エチル 1-(3-(2-(4-シクロプチルー 2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-5-(1H-テトラゾール-5-イル)-2, 4-ジオキソ-3-(1H, 3H)-ピリミジンアセートを実施例56と同様に処理し、表題物を得た。

(工程1) 1-(3-(2-(4-シクロプチル-2- チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-3-(4-) キシベンジル) -5-(2-(4-) + +) マンジル) -2H- テトラゾール-5- イル) -2 、4-(1H , 3H) - ピリミジンジオンの合成

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1. 9 1~2. 08 (2H, m), 2. 28~2. 41 (4 H, m), 3. 65~3. 74 (1H, m), 3. 77 (3H, s), 3. 78 (3H, s), 5. 19 (2H, s), 5. 76 (2H, s), 6. 82~6. 88 (4H, m), 6. 9 7 (1H, s), 7. 35~7. 37 (2H, m), 7. 41 (1H, d), 7. 50 (1H, t), 7. 55~7. 57 (2H, m), 7. 6

0 (1H, s), 7.65 (1H, d), 8. 26 (1H, s).

【0315】(工程2) 1-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3-(4-メトキシベンジル)-5-(1H-テトラゾール-5-イル)-2,4-(1H,3H)-ピリミジンジオンの合成

1-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-3-(4-メトキシベンジル) -5-(2-(4-メトキシベンジル) -2 H-テトラゾール-5-イル) -2, 4-(1H, 3H) -ピリミジンジオンを実施例1の工程5と同様に処理し、3位に4-メトキシベンジル基を有する表題物を得た。

融点 205~207℃ (decomp.) (再結晶溶

媒:クロロホルム-n-ヘキサン); I Rνmax c m⁻¹ 2216, 1718, 1666, 1604; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.88 ~2.02(2H, m), 2.20~2.30(4H, m), 3.65~3.69(1H, m), 3.72(3H, s), 5.08(2H, s), 6.82~6.91(2H, m), 7.36~

d), 7.78 (1H, d), 7.92 (1H, s), 8.67 (1H, s); MS (EI) m/z 537 (M⁺).

7. 38 (2H, m), 7. 54 (1H, s),

7. 64 (1H, t), 7. 71 (1H,

【0316】 [実施例91] N-(1H-テトラゾール-5-イル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミド:3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)安息香酸と5-アミノ-1H-テトラゾールを実施例88と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $244\sim246$ \mathbb{C} (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーnーへキサン); IR ν max cm $^{-1}$ 2220, 1674, 1590; NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.84 \sim 2.10(2H, m), 2.19 \sim 2.35(4H, m), 3.68(1H, m), 7.56(1H, s), 7.69(1H, t), 7.95(1H, d), 8.17(1H, d), 8.41(1H, s), 12.57(1H, s); MS (FAB) m/z 351(M⁺+1); 元素分析値 C_{17} H₁₄N₆OSの計算値(%) C,58.27; H,4.03; N,23.98, 測定値(%) C,58.10; H,4.00; N,23.82.

【0317】 [実施例92] N-(1H-テトラゾール-5-イル)-3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-メトキシベンズアミド:(工程1)3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-メトキシ安息香酸の合成

参考例18と同様にして得られたエチル 3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) -6 ーメトキシフェニルカルボキシレートを参考例19と同 様に処理し、3-(2-(4-シクロプチル-2-チア ゾリル) エチニル) -6-メトキシ安息香酸を得た。 融点 141~144℃ (decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルムーnーヘキサン); IRvmax cm ⁻¹ 2212, 1700, 1678; NMR (400 MHz, CDCl₃) δ ppm 1. 89~2. 41 (6 H, m), 3. $65 \sim 3$. 74 (1 H, m), 4. 12 (3H, s), 6. 96 (1H, s), 7.08(1H, d), 7.77(1H, dd), 8.41 (1H, d); MS (EI) m/z 313 (M⁺); 元素分析值C₁₇H₁₅N₃O S・1/4H₂ Oの計算値(%) C, 64.23; H, 4.91; N, 4.41, 測定値(%) C, 64. 38; H, 4. 89; N, 4. 16. 【0318】(工程2) N-(1H-テトラゾールー 5-イル) -3- (2- (4-シクロブチル-2-チア ゾリル) エチニル) -6-メトキシベンズアミドの合成 3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチ ニル) -6-メトキシ安息香酸と5-アミノー1H-テ トラゾールを実施例88と同様に処理し、表題物を得 た。

融点 $233\sim235$ $^{\circ}$ $^{\circ}$

【0319】 [実施例93] N-(1H-テトラゾール-5-イル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-イソプロポキシベンズアミド:

(工程1) 3-(2-(4-シクロブチル-2-チア ゾリル) エチニル) -6-イソプロポキシ安息香酸の合成

参考例18と同様にして得られたイソプロピル 3- (2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) -6-イソプロポキシフェニルカルボキシレートを、参考例19と同様に処理し、3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) -6-イソプロポキシ安息香酸を得た。

融点 168~170℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); IR ν max c m⁻¹ 2216, 1738, 1692, 1602, 1500; NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 1.52 (6H, d), 1.89~2.41 (6H, m), 3.65~3.72 (1H, m), 4.86~4.96 (1H, m), 6.96 (1H, s), 7.06 (1H, d), 7.74 (1H, dd), 8.43 (1H, d), 10.98 (1H, s); MS (EI) m/z 341 (M⁺); 元素分析値C19H₁₉N₃OS·1/4H₂Oの計算値 (%) C, 65.97; H, 5.68; N, 4.05, 測定値 (%) C, 66.09; H, 5.59; N, 3.83.

【0320】(工程2) N-(1H-テトラゾール-5-イル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル)-6-イソプロポキシベンズアミドの合成

3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-イソプロポキシ安息香酸と5-アミノ-1 H-テトラゾールを実施例88と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $211\sim214$ ^{°C} (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーnーへキサン); IR ν max cm $^{-1}$ 2216, 1664, 1592; NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.34 (6H, d), 1.88 \sim 2.30 (6H, m), 3.61 \sim 3.68 (1H, m), 4.83 \sim 4.86 (1H, m), 7.32 (1H, d), 7.50 (1H, s), 7.80 (1H, d), 7.91 (1H, s), 11.88 (1H, brs); MS (EI) m/z 408 (M⁺); 元素分析値C₂₀H₂₀N₆O₂Sの計算値(%) C,58.81; H,4.93; N,20.57, 測定値(%) C,58.61; H,5.05; N,20.58.

【0321】 [実施例94] N-(1H-テトラゾールー5-イル) -3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) -2-メチルベンズアミド: (工程1) 3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) -2-メチル安息香酸の合成参考18と同様にして得られたエチル 3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) -2-メチルフェニルカルボキシレートを、参考例19と同様に処理し、3-(2-(4-シクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) -2-メチル安息香酸を得た。

融点 115℃ (再結晶溶媒:クロロホルム-n-ヘキサン); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.85~2.40 (6H, m), 2.55 (3H, s), 3.69 (1H, m), 7.4

4 (1H, t), 7.48 (1H, s), 7.72 (1H, d), 7.80 (1H, d), 13.40 (1H, br). 【0322】(工程2) N-(1H-テトラゾールー

5-イル) -3-(2-(4-シクロプチル-2-チア ゾリル) エチニル) -2-メチルベンズアミドの合成 3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチ ニル) -2-メチル安息香酸と5-アミノ-1H-テト ラゾールを実施例88と同様に処理し、表題物を得た。 融点 289℃ (decomp.) (再結晶溶媒:クロ ロホルムーエタノール); $IRv max cm^{-1} 164$ 6; NMR $(400MHz, DMSO-d_6)$ δpp m 1. $85\sim2$. 35 (6H, m), 2. 57 s), 3.66 (1H, m), 7.44 t), 7.56 (1H, s), 7.6 9 (1H, d), 7.80 (1H, d), 1 2. 52 (1H, br s); MS (FAB) m/ z 365 (M⁺ +1); 元素分析値C₁₈H₁₆N₆ OSの計算値(%) C, 59.32; H, 4.4 3; N, 23.06, 測定值(%) C, 59.1 3; H, 4. 48; N, 23. 34.

【0323】 [実施例95] N-(1H-テトラゾー ルー5ーイル) -3- (2- (4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) -4-フルオロベンズアミド: (工程1) 3-(2-(4-シクロプチル-2-チア ゾリル) エチニル) -4-フルオロ安息香酸の合成 参考例18と同様にして得られたエチル 3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) -4 ーフルオロフェニルカルボキシレートを、参考例19と 同様に処理し、3-(2-(4-シクロブチル-2-チ アゾリル) エチニル) -4-フルオロ安息香酸を得た。 融点 156℃ (再結晶溶媒:クロロホルム-n-ヘキ $\forall \nu$); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.82~2.35 (6H, m), 3.68 (1H, m), 7.53(1H, t), 7.6 0 (1H, s), 8.09 (1H, m), 8. 21 (1H, m), 13.39 (1H, br). 【0324】 (工程2) N- (1H-テトラゾールー 5-イル) -3-(2-(4-シクロプチル-2-チア ゾリル) エチニル) -4-フルオロベンズアミドの合成 3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチ ニル) -4-フルオロ安息香酸と5-アミノー1H-テ トラゾールを実施例88と同様に処理し、表題物を得 た。

融点 247~259℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノール); IRνmax cm⁻¹ 1668; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm1.85~2.40 (6H, m), 3.69 (1H, m), 7.63 (2H, m), 8.24 (1H, m), 8.50 (1H, m), 12.50 (1

H, br); MS (FAB) m/z 369 (M⁺ +1) ; 元素分析値C₁₇H₁₃FN₆ OSの計算値 (%) C, 55. 42; H, 3. 56; N, 2 2.81, 測定値(%) C,55.47; H, 3. 76; N, 23. 17. 【0325】 [実施例96] Nー(1 Hーテトラゾー ルー5ーイル)-3-(2-(4-シクロプチルー2-チアソリル) エチニル) -6-メチルベンズアミド: (工程1) 3-(2-(4-シクロプチル-2-チア ゾリル) エチニル) -6-メチル安息香酸の合成 参考例18と同様にして得られたエチル 3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) -6 -メチルフェニルカルボキシレートを、参考例19と同 様に処理し、3-(2-(4-シクロプチル-2-チア ゾリル) エチニル) -6-メチル安息香酸を得た。 融点 163~165℃ (decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルムーメタノール); NMR(400M Hz, CDCl₃) δ ppm 1. 90~2. 00 (1 H, m), $2.00\sim2.10$ (1H, m), 2. $20\sim2$. 50 (4H, m), 2. 68 (3 H, s), $3.70\sim3.80(1H, m)$, 6. 98 (1H, s), 7. 29 (1H, d), 7. 63 (1H, d), 8. 31 (1H, s). 【0326】 (工程2) N-(1H-テトラゾール-5ーイル) -3-(2-(4-シクロプチル-2-チア ソリル) エチニル) -6-メチルベンズアミドの合成 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチ ニル) -6-メチル安息香酸と5-アミノ-1H-テト ラゾールを実施例88と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $250\sim253$ °C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.80~2.00 (1H, m), 2.00~2.10 (1H, m), 2.20~2.40 (4H, m), 2.55 (3H, s), 3.60~3.80 (1H, m), 7.49 (1H, d), 7.57 (1H, s), 7.77 (1H, d), 7.97 (1H, s), 8.02 (1H, br), 12.52 (1H, s); MS (FAB) m/z 365 (M+1);元素分析値 $C_{18}H_{16}N_6$ OS·3/4 H_2 Oの計算値(%) C,58.52; H,4.52; N,21.55, 測定値(%) C,58.75; H,4.59; N,21.35.

【0327】 [実施例97] N-(1H-テトラゾール-5-イル)-2-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンズアミド:

(工程1) 2-(2-(4-シクロブチルー2-チア ブリル) エチニル) 安息香酸の合成参考例18と同様にして得られたエチル 2-(2(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニルカルボキシレートを、参考例19と同様に処理し、2-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) 安息香酸を得た。

融点 142~145℃ (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.80~1.90 (1H, m), 1.90~2.00 (1H, m), 2.20~2.50 (4H, m), 3.70~3.80 (1H, m), 7.08 (1H, s), 7.50~7.70 (4H, m), 12.50~12.70 (1H, br).

【0328】 (工程2) N-(1H-テトラゾールー 5-イル)-2-(2-(4-シクロブチルー2-チア ゾリル)エチニル)ベンズアミドの合成

2- (2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) 安息香酸と5-アミノ-1H-テトラゾールを実施例88と同様に処理し、表題物を得た。

融点 168~170℃ (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.80~1.90 (1H, m), 1.90~2.00 (1H, m), 2.10~2.40 (4H, m), 3.60~3.80 (1H, m), 7.07 (1H, s), 7.50~7.70 (4H, m), 12.20 (1H, br); MS (FAB) m/z 351 (M⁺ +1).

【0329】 [実施例98] (E) -5-(2-(3 - (2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) エテニル) -1H-テトラゾール: (工程1) (E) -5-(2-(3-イオドフェニル) エテニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H -テトラゾールの合成

(E) -5-(2-(3-7)) エテニル)エテニル) -1 Hーテトラゾールを実施例1 の工程3 と同様に処理 し、(E) -5-(2-(3-7)) エテニル)エテニ ル)-2-(4-3) トキシベンジル)-2 Hーテトラゾールを得た。

融点 115~116℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 3) δ p p m 3.80 (3H, s), 5.69 (2H, s), 6.88~6.92 (2H, m), 7.10 (1H, d), 7.11 (1H, t), 7.34~7.37 (2H, m), 7.48 (1H, d), 7.59 (1H, d), 7.6 4 (1H, d), 7.88 (1H, s); MS (EI) m/z 418 (M⁺); 元素分析値C₁₇H 15 I N₄ Oの計算値 (%) C, 48.82; H, 3.62; N, 13.40, 測定値 (%) C, 48.99; H, 3.72; N, 13.24.

【0330】(工程2) (E)-5-(2-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニ ル) フェニル) エテニル) -2-(4-メトキシベンジ ル) -2H-テトラゾールの合成 (E) -5- (2-(3-イオドフェニル) エテニル) -2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール と4-シクロプチルー2-エチニルチアゾールを実施例 1の工程4と同様に処理し、(E)-5-(2-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニ ル)フェニル)エテニル)-2-(4-メトキシベンジ ル) -2H-テトラゾールを淡油状物として得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1. 9 $1\sim2.08$ (2H, m), 2.30 ~2.30 (4 H, m), 3.66 \sim 3.74(1H, m), 3.80 (3H, s), 5.70 (2H, s), 6. $89 \sim 6$. 92 (2H, m), 6. 96 (1)s), 7.14 (1H, d), 7.35 \sim 7. 41 (3H, m), 7. $53\sim7$. 56 (2 H, m), 7.68 (1H, d), 7.75 (1H, s). 【0331】(工程3) (E)-5-(2-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニ ル) フェニル) エテニル) -1H-テトラゾールの合成 (E) -5-(2-(3-(2-(4-))2)2)+)-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) エテニル) -2 (4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実 施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。 融点 158~168℃ (decomp.) (再結晶溶 ⁻¹ 2216, 1650, 1598, 1574, 155 4, 1504; NMR (400MHz, DMSO-d ₆) δppm 1.86~2.03 (2H, m), 2. $18\sim2$. 33(4H, m), $3.63\sim3$. 71 (1H, m), 7.47 (1H, d), 7. 53 (1H, s), 7. 54 (1H, t), 7. $63 \sim 7$. 67 (1 H, m), 7. 65 (1H, d), 7.83(1H, d), 8.04 (1H, s); MS (EI) m/z 333 (M⁺) ; 元素分析値C₁₈H₁₅N₅ Sの計算値(%)

C, 64.84; H, 4.53; N, 21.0
1, 測定値(%) C, 65.05; H, 4.6
0; N, 20.70.
【0332】 [実施例99] (E) -5-(2-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1-プロペン-1-イル) -1H-テトラゾール:
(工程1) (E) -5-(2-(3-イオドフェニ

(工程1) (E) -5-(2-(3-イオドフェニル) -1-プロペン-1-イル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成

ペンー1ーイル) -1 Hーテトラゾールを実施例1 の工程3 と同様に処理し、(E) -5 - (2 - (3 - イオドフェニル) -1 - プロペン-1 - イル) -2 - (4 - メトキシベンジル) -2 Hーテトラゾールをアモルファスとして得た。

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3)$ $\delta \text{ppm} 2.6$ 6(3 H, d), 3.79(3 H, s), 5.72(2 H, s), $6.75 \sim 7.45(8 \text{H}, \text{m})$, 7.88(1 H, s). [0333] (工程2) (E) $-5-(2-(3-(2-(4-\nu)2)\pi)\pi)\pi$ エチニ

ル)フェニル) -1-プロペン-1-イル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成(E) -5-(2-(3-イオドフェニル) -1-プロペン-1-イル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、(E) -5-(2-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1-プロペン-1-イル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを褐色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.8 $5\sim2$. 44 (6H, m), 2.62 (3H, d), 3.70 (3H, s), 3.80 (3H, s), 5.72 (2H, s), 6.86 \sim 7.80 (10H, m).

【0334】(工程3) (E) -5-(2-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1-プロペン-1-イル) -1H-テトラゾールの合成

(E) -5-(2-(3-(2-(4-)2017チル-2-47)1) エチニル) フェニル) -1-7ロペン -1-4ル) -2-(4-3) トキシベンジル) -2 Hーテトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $134\sim135$ $^{\circ}$ (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\wedge$ キサン); IRv_{max} cm^{-1} 2216; N $MR (400MHz, DMSO-d_6-CDCl_3) \delta$ ppm $1.85\sim2.42 (6H, m), 2.68 (3H, d), 3.69 (1H, m), 6.80 (1H, s), 7.15 (1H, s), 7.48 (1H, t), 7.58 (1H, d), 7.63 (1H, d), 7.78 (1H, m); <math>MS$ (FAB) m/z 348 (M^+ + 1); 元素分析値 $C_{19}H_{17}N_5$ $S \cdot 1/4H_2$ OO計算値 (%) C, 64.84; H, 5.01; N, 19.90, 測定値 (%) C, 65.01; H, 19.90, 19.89. 19.19.89. 19.19.89.

【0335】 [実施例100] (E) -5-(1-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エ

チニル) フェニル) -1 - プロペン-2 - イル) -1 H - テトラゾール:

(E) -5-(21(3-7)+7)=2 -1-7 -1-

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 2. 3 4 (3 H, d), 3. 80 (3 H, s), 5. 69 (2 H, s), 6. 90 (2 H, d), 7. 13 (1 H, t), 7. 47 (3 H, m), 7. 63 (2 H, m), 7. 76 (1 H, s). 【0336】(工程2) (E) -5-(1-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル)フェニル) -1-プロペン-2-イル) -2-(4-メトキシベンジル) -2 H-テトラゾールの合成

(E) -5-(1-(3-7)+2) (E) -5-(1-(3-7)+2) (E) -5-(1-(3-1)+2) (E) -2-(4-2)+2 (E) (E) -2-(4-2)+2 (E) -2-(4-2)+2 (E) -2-(4-2)+2 (E) -2-(4-2)+2 (E)

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.8 $5\sim2$. 40 (6H, m), 2.38 (3H,

d), 3. 70 (1H, s), 3. 77 (3H, s), 5. 70 (2H, s), 6. 90 (2H, d), 6. 95 (1H, s), 7. 38 (2H, d), 7. 43 (1H, m), 7. 51 (1H, m), 7. 64 (1H, br s), 7. 71 (1H, br s).

【0337】(工程3) (E) -5-(1-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル)フェニル) -1-プロペン-2-イル) -1H-テトラゾールの合成

融点 $134\sim136$ C (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); $IRv\max cm^{-1}$ 2216; NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.85 \sim 2.40 (6H, m), 2.42 (3H, d), 3.78 (1H, m), 7.04 (1H,

s), 7.35~7.45(4H, m), 7.61(1H, s); MS(EI)m/z 347(M⁺); 元素分析値C19H17N5Sの計算値(%)C,65.68; H,4.93; N,20.16, 測定値(%) C,65.40; H,5.05; N,19.89.

【0338】 [実施例101] (E) -5-(2-(4-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エ チニル) -2-チエニル) -2-エテニル) -1H-テ トラゾール:

(工程1) (E) -5-(2-(4-プロモー2-チェニル) -2-エテニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成

(E) -5-(2-(4-プロモ-2-チェニル)-2 -エテニル)-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、(E) -5-(2-(4-プロモ-2-チェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを得た。

融点 83~84℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーnーヘキサン); NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 3.79 (3H, s), 5.67 (2H, s), 6.88~6.95 (2H, m), 7.07 (1H, s), 7.17 (1H, s), 7.34~7.36 (2H, m), 7.85 (1H, d).

【0339】 (工程2) (E) -5-(2-(4-イ オド-2-チエニル) -2-エテニル) -2-(4-メ トキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成

(E) -5-(2-(4-ブロモー2-チエニル) -2-エテニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例16の工程2と同様に処理し、

(E) -5-(2-(4-7)+2-5) -2-(4-7)+2-7 -2-(4-7)+2-7 -2+2 -2+2 -2+2 -2+2 -2+2 -

融点 103~104°C (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDCl 3) δppm 3.80 (3H, s), 5.68 (2H, s), 6.89~6.94 (2H, m), 7.13 (1H, s), 7.34~7.37 (3H, m), 7.73 (1H, d).

【0340】 (工程3) (E) -5-(2-(4-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニ ル) -2-チエニル) -2-エテニル) -2-(4-メ トキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成

- (4-メトキシベンジル) - 2H-テトラゾールを得た。

融点 133~135℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1₃) δppm 1.90~2.10(2H, m), 2.28~2.38(4H, m), 3.64~3.73(1H, m), 3.80(3H, s), 5.68(2H, s), 6.89~6.92(2H, m), 6.94(1H, s), 6.95(1H, d), 7.34~7.37(2H, m), 7.56(1H, s), 7.74(1H, d).

【0341】(工程4) (E) -5-(2-(4-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-チエニル) -2-エテニル) -1H-テトラゾールの合成

融点 $156\sim163$ [°]C(decomp.)(再結晶溶媒:クロロホルムーnーへキサン); $IR\nu$ max cm $^{-1}$ 2216; NMR(400MHz,DMSO-d6) δ ppm $1.83\sim2.05$ (2H, m), $2.18\sim2.32$ (4H, m), $3.62\sim3.70$ (1H, m), 7.12(1H, d), 7.52(1H, s), 7.74(1H, s), 7.80(1H, d), 8.21(1H, s); 1.800(1H, d), 1.801(1H, s); 1.801(1H); 1.801(

【0342】 [実施例102] (E) -5-(2-(5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エ チニル) -2-ベンゾ [b] チエニル) -2-エテニ ル) -1H-テトラゾール:

(工程1) (E) -5-(2-(5-7)+2-4)ンソ [b] チエニル) -2-(4-3)+2-4トキシベンジル) -2H-7トラゾールの合成

融点 144~146℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 3) δppm 3.80 (3H, s), 5.69 (2H, s), 6.90(2H, d), 7.0 0(1H, d), 7.26(1H, s), 7.3 6(2H, d), 7.52(1H, d), 7. 59(1H, d), 7.87(1H, d), 8.08(1H, s).

【0343】(工程2) (E) -5-(2-(5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニ ル) -2-ベンゾ [b] チエニル) -2-エテニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの 合成

(E) -5-(2-(5-7)+2-2-4) [b] チェニル) -2-4+2-2-4 (b] チェニル) -2-4+2-2-4 (c) -2+2-2-4 (c) -2+2-2-4 (c) -2+2-4 (c)

融点 145~148℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n - ヘキサン); NMR (400MHz, CDC1 s) δppm 1.89~2.11(2H, m), 2.30~2.41(4H, m), 3.68~3.76(1H, m), 3.80(3H, s), 5.70(2H, s), 6.89~6.92(2H, m), 6.95(1H, s), 7.02(1H, d), 7.38~7.35(3H, m), 7.52(1H, d), 7.77(1H, d), 7.89(1H, d), 7.96(1H, s).

【0344】(工程3) (E) -5-(2-(5-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニ ル) -2-ベンゾ [b] チエニル) -2-エテニル) -1H-テトラゾールの合成

(E) -5-(2-(5-(2-(4-)2017チルー2-チアゾリル) エチニル) -2-ベンゾ [b] チェニル) -2-エテニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $222\sim224$ C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノールーnーへキサン); I R ν max c m⁻¹ 2216, 1638; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ p p m 1.86~2.03 (2H, m), 2.21~2.31 (4H, m), 3.63~3.72 (1H, m), 7.11 (1H, d), 7.53 (1H, s), 7.64 (1H, d), 7.82 (1H, s), 7.98 (1H, d), 8.12 (1H, d), 8.20 (1H, s); MS (FAB) m/z 390 (M⁺+1); 元素分析値C₂₀H₁₅N₅S₂の計算値 (%) C, 61.67; H, 3.88; N, 1

7. 98. 測定値(%) C, 61.97; H, 3. 99; N, 17. 61. 【0345】[実施例103] N-(3-(2-(4 ーシクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ ル) -1H-テトラゾール-5-カルボキサミド: (工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2- (4-メト キシベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサ ミドの合成 3-(2-(4-シクロプチル-2-チアソリル)エチ ニルアニリン509mg、参考例19のカルボン酸1. 14g、1-エチル-1'-(3-ジメチルアミノ)プ ロピルカルボジイミド塩酸塩1.04g及び4ージメチ ルアミノピリジン598mgに塩化メチレン10mlを 加え、室温で15時間撹拌した。 反応液をクロロホルム 100mlで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、 飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒 を留去し得られる残渣をシリカゲルを用いるカラムクロ マトグラフィー (溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチル= 3:2) で精製し、得られた粗結晶をクロロホルムーエ ーテルから再結晶し、N-(3-(2-(4-シクロブ チルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサミド1gを淡黄色針状晶として得た。 融点114~115℃; NMR (400MHz, CD Cl₃) δ ppm 1. 88~2. 11 (2H, m), $2.27\sim2.41(4H, m)$, 3.72 (1H, m), 3.80 (3H, s), 5. 79 (2H, s), 6. 90 (2H, d), 96 (1H, s), 7.37 \sim 7.42 (4H, m), 7.77 (1H, ddd), 7.78 (1 H, s), 8.06(1H, s); 元素分析值C 25H₂₂N₆O₂Sの計算値(%)C,63.81; H, 4. 71; N, 17. 86, 測定値(%) C, 63. 73; H, 4. 84; N, 17. 78. 【0346】(工程2) N-(3-(2-(4-シク ロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -1 H-テトラゾール-5-カルボキサミドの合成 N- (3- (2- (4-シクロプチル-2-チアゾリ ル) エチニル) フェニル) -2- (4-メトキシベンジ ル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサミドを実施 例1の工程3と同様に処理し、表題物を得た。 融点 214~215℃ (decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルムーエタノールーn-ヘキサン); I $R \nu \text{max cm}^{-1}$ 2216, 1660; NMR (40 0MHz, $DMSO-d_6$) δppm 1. $85\sim2$. $06 (2H, m), 2.20\sim2.51 (4H,$ m), 3.68 (1H, m), 7.44 \sim 7.5 2 (3H, m), 7.95 (1H, d), 8. 16 (1H, s); 元素分析値C₁₇H₁₄N₆ OSの 計算値(%) C, 58.27; H, 4.03; N, 23.98, 測定値(%) C,58.15; H, 4. 25; N, 23. 55. 【0347】 [実施例104] N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー2ーメ チルフェニル) -1H-テトラゾール-5-カルボキサ ミド: (工程1) 3-(2-(4-シクロプチル-2 ーチアゾリル) エチニル) -2-メチルアニリンの合成 3-イオド-2-メチルニトロベンゼンと4-シクロブ チルー2-エチニルチアゾールを参考例16同様に処理 し、引き続き参考例17と同様に処理して、3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) -2 ーメチルアニリンを淡褐色油状物として得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.9 $1 \sim 2.40 (9 H, m), 3.70 (1 H,$ m), 6.71 (1H, dd), 6.94 (1 H, s), 6.99 \sim 7.05(2H, m). 【0348】 (工程2) N-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー2ーメチルフ ェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テト ラゾールー5ーカルボキサミドの合成 参考例19のカルボン酸1.26g、及び塩化チオニル 0.5mlにトルエン5ml及び触媒量のDMFを加 え、3時間加熱還流した。冷却後、反応液を留去した。 残渣を塩化メチレン20m1に溶解し、これを3-(2 - (4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-メチルアニリン966mg及びトリエチルアミン 0. 8 m l の塩化メチレン 2 0 m l 溶液に、0℃で撹拌 下に加えた。滴下終了後、反応液を室温で2時間撹拌し た。反応液を1N塩酸50mlに注ぎ、クロロホルムで 抽出した。抽出層を飽和炭酸水素ナトリウムで洗浄後、 硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残 液をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶 出液:クロロホルム:メタノール=100:1)で精製 し、N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾ リル) エチニル) -2-メチルフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボ キサミド1.95gを褐色油状物として得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.9 $2\sim2.08$ (2H, m), 2.28 ~2.40 (4 H, m), 2.56 (3H, s), 3.66 \sim 3.72 (1H, m), 3.80 (3H, s), 5.80 (2H, s), 6.90 (2H, d), 6.97(1H, s), 7.27(1H, t), 7.42 (2H, d), 7.46 (1 H, d), 8. 11 (1H, d), 8. 82 (1 H. s). 【0349】(工程3) N-(3-(2-(4-シク ロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) -2-メチルフ ェニル) -1H-テトラゾール-5-カルボキサミドの 合成N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-メチルフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボ、キサミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $190\sim191$ C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノールーnーへキサン); I R ν max c m $^{-1}$ 2208, 1700, 1672, 1600, 1542, 1504; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ p p m 1.88 \sim 2.03(2H, m), 2.19 \sim 2.31(4H, m), 2.42(3H, s), 3.63 \sim 3.72(1H, m), 7.36(1H, t), 7.51 \sim 7.54(1H, m), 7.54(1H, s), 7.60(1H, d), 10.96(1H, s); MS (FAB) m/z 365(M + 1); 元素分析値C₁₈H₁₆N₆OSの計算値(%) C,59.32; H,4.43; N,23.07, 測定値(%) C,59.28; H,4.34; N,23.26.

【0350】 [実施例105] N-(3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) -6-メチルフェニル) -1H-テトラゾール-5-カルボキサミド:(工程1) 3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) -6-メチルアニリンの合成3-イオド-6-メチルニトロベンゼンと4-シクロプチルー2-エチニルチアゾールを参考例16同様に処理し、引き続き参考例17と同様に処理して、3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) -6-メチルアニリンを得た。

融点 125~126℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n - (n + y); IR $v \max c m^{-1}$ 3460, 33 .48, 2980, 2940, 2200, 1624, 15 66; NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1. $90\sim2$. 07 (2H, m), 2. 17 (3 s), $2.28\sim2.38(4H, m)$, 3. $63\sim3$. 70 (1H, m), 6. 88 (1 H, d), 6. 91 (1H, s), 6. 94 (1 dd), 7.03(1H, d); MS(FA B) m/z 269 (M⁺+1); 元素分析値C₁₆H 16N₂ Sの計算値(%) C, 71.60; H, 6. 01; N, 10.44, 測定値(%) C, 71.3 2; H, 5.85; N, 10.37. 【0351】(工程2) N-(3-(2-(4-シク ロプチルー2ーチアソリル) エチニル) ー6ーメチルフ ェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テト

参考例19のカルボン酸と3-(2-(4-シクロプチ

ルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ーメチルアニリン

を実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-

ラゾールー5ーカルボキサミドの合成

(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-メチルフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサミドを得た。

融点 138~140℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー $n - \uparrow + \nu$); IR $\nu \max cm^{-1}$ 3408, 22 12, 1704, 1614; NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 1. 93~2. 07 (2H, m), 2.29 \sim 2.36(4H, m), 9 (3H, s), 3. $66 \sim 3$. 71 (1H, m), 3.80(3H, s), 5.80(2H, s), 6.89 \sim 6.91(2H, m), 6. 94 (1H, s), 7.23 (1H, d), 7. 35 (1H, d), 7. $40 \sim 7$. 42 (2) H, m), 8.32 (1H, s), 8.78 (1H, s); MS (FAB) m/z 485 (M ⁺ + 1); 元素分析値C₂₆H₂₄N₆ O₂ Sの計算値 (%) C, 64.44; H, 4.99; N, 17. 35, 測定値(%) C, 64.22; H, 5.1 4; N, 17. 64.

【0352】(工程3) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-メチルフェニル)-1H-テトラゾール-5-カルボキサミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-メチルフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $214\sim215$ \mathbb{C} (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノールーnーへキサン); IR ν max ν cm⁻¹ 3412, 3092, 2204, 1710, 1570; NMR (400MHz, DMSO-d₆) ν ppm1. 85 ν 2. 02 (2H, m), 2. 20 ν 2. 31 (4H, m), 2. 50 (3H, s), 3. 64 ν 3. 70 (1H, m), 7. 41 (1H, d), 7. 50 ν 7. 51 (1H, m), 7. 54 (1H, s), 7. 68 (1H, s), 10. 84 (1H, s); MS (FAB) m/z 365 (M⁺ +1); 元素分析値C₁₈H₁₆N₆OS·1/4H₂Oの計算値(%)C, 58. 60; H, 4. 51; N, 22. 78, 測定値(%)C, 58. 76; H, 4. 53; N, 23. 16.

【0353】 [実施例106] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-メトキシフェニル) -1H-テトラゾール-5-カルボキサミド:

(工程1) 3-(2-(4-シクロブチルー2-チア プリル) エチニル) -2-メトキシアニリンの合成 3- 4オドー2-メトキシニトロベンゼンと4-シクロプチルー2-エチニルチアゾールを参考例1 6 同様に処理し、引き続き参考例1 7と同様に処理して、3- (2- (4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) ー 2-メトキシアニリンを淡黄色油状物として得た。 NMR (400MHz, CDC 1_3) δ ppm 1. 90~2.07(2H, m), 2.28~2.39(4H, m), 3.65~3.74(1H, m), 4.00(3H, s), 6.77(1H, d), 6.88(1H, t), 6.92~6.94(2H, m).

【0354】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メトキシフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-カルボキサミドの合成

参考例19のカルボン酸と3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メトキシアニリンを実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メトキシフェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-カルボキサミドを得た。

融点 $137 \sim 138$ C; IR ν max c m⁻¹ 338 4, 3100, 2212, 1704, 1606; NM R $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3)$ δ p p m $1.91 \sim 2.09$ (2H, m), $2.29 \sim 2.40$ (4H, m), $3.68 \sim 3.73$ (1H, m), 3.80 (3H, s), 4.17 (3H, s), 5.80 (2H, s), 6.90 (2H, d), 6.99 (1H, s), 7.13 (1H, t), 7.34 (1H, d), 7.42 (2H, d), 8.58 (1H, d), 9.56 (1H, s); MS (FAB) m/z 501 $(\text{M}^+ + 1)$; 元素分析值 C_{26} H₂₄ N₆O₃ S·1/4 H₂ Oの計算值 (%) C, 61.83; H, 4.89; N, 16.64, 測定值 (%) C, 61.96; H, 4.87; N, 16.19.

【0355】(工程3) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メトキシメチルフェニル)-1H-テトラゾール-5-カルボキサミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-メトキシフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $220\sim221$ [°]C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノールーnーへキサン); I R ν max c m⁻¹ 3384,3090,2212,1606; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ p

pm 1.86~2.03(2H, m), 2.21 ~2.33(4H, m), 3.64~3.72(1 H, m), 4.03(3H, s), 7.27 (1H, t), 7.53(1H, d), 7.5 6(1H, d), 8.02(1H, d), 1 0.32(1H, s); MS(EI) m/z 38 $0(M^{+})$; 元素分析值 $C_{18}H_{16}N_{6}O_{2}$ Sの計算値(%) C,56.82; H,4.24; N,2 2.10, 測定値(%) C,56.63; H,4.38; N,21.73.

【0356】 [実施例107] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-メートキシフェニル) -1H-テトラゾール-5-カルボキサミド:

(工程1) 3-(2-(4-シクロプチルー2-チア ゾリル) エチニル) -6-メトキシアニリンの合成 3-イオドー6-メトキシニトロベンゼンと4-シクロ プチルー2-エチニルチアゾールを参考例16同様に処 理し、引き続き参考例17と同様に処理して、3-(2) - (4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-メトキシアニリンを淡黄色油状物として得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.8 $9\sim2.07$ (2H, m), 2.28 ~2.38 (4 $H, m), 3.63\sim3.72(1H, m),$ 3.87 (3H, s), 6.75 (1H, d), 6.89 (1H, s), 6.92 (1H, d), 7.01(1H, dd). 【0357】(工程2) N-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ーメトキシ フェニル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テ トラゾールー5ーカルボキサミドの合成 参考例19のカルボン酸と3-(2-(4-シクロブチ ルー2-チアゾリル) エチニル) -6-メトキシアニリ ンを実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニ ル) -6-メトキシフェニル) -2-(4-メトキシベ ンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサミドを 得た。

融点 $158\sim160^{\circ}$ C; $IRv max cm^{-1} 338$ 4, 2212, 1698, 1612, 1550, 1510; $NMR (400MHz, CDCl_3) \delta ppm$ 1. $91\sim2$. 07(2H, m), $2.29\sim2$. 38(4H, m), $3.64\sim3$. 73(1H, m), $3.80\cdot(3H, s)$, 3.98(3H, s), 5.80(2H, s), $6.89\sim6$. 92(4H, m), 7.38(1H, dd), 7.41(1H, d), 8.75(1H, d), 9.46(1H, s); $MS(EI) m/z 500(M^+)$; πs πs

6.79, 測定値(%) C,62.15; H,4.93; N,16.75.

【0358】 (工程3) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-メトキシメチルフェニル) -1H-テトラゾール-5-カルボキサミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-メトキシフェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

【0359】 [実施例108] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N-(エトキシカルボニルメチル) -1H-テトラゾール-5-カルボキサミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 -チアゾリル) エチニル) フェニル) グリシン エチル エステルの合成

3- (2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニルアニリン301mg、炭酸カリウム204mg、及びプロム酢酸エチル エステル0.145mlにDMF5mlを加え、室温で24時間撹拌した。反応液を酢酸エチル300mlで希釈し、飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)グリシン エチル エステル214mgを得た。

融点 $110\sim112$ °C; NMR (400MHz, CD Cl₃) δ ppm 1. 31 (3H, t), 1. 88 \sim 2. 10 (2H, m), 2. $27\sim2$. 42 (4H, m), 3. 69 (1H, m), 3. 90 (2H, d), 4. 26 (2H, q), 4. 37 (1H, t), 6. $64\sim6$. 67 (1H, m), 6. 80 (1H, t), 6. 93 (1H, s), 6. 99 (1H, d), 7. 17 (1H, t).

【0360】(工程2) N-(3-(2-(4-シク

ロプチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N - (エトキシカルボニルメチル) -2- (4-メトキシ ベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサミド の合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) グリシン エチル エステルと参考例19のカルボン酸を実施例104の工程2と同様に処理し、<math>N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N-(エトキシカルボニルメチル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサミドを淡黄色油状物として得た。

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3)$ δppm 1. 2 9 (3H, t), 1. $91\sim2$. 08 (2H, m), 2. $28\sim2$. 39 (4H, m), 3. 6 $5\sim3$. 73 (1H, m), 3. 75 (3H, s), 4. 24 (2H, q), 4. 58 (2H, s), 5. 54 (2H, s), 6. 82 (1H, d), 6. 97 (1H, s), 7. 10 (1H, d), 7. $19\sim7$. 23 (2H, m), 7. 43 ~7 . 45 (1H, m), 7. 48 (1H, s).

【0361】(工程3) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-N-(エトキシカルボニルメチル)-1H-テトラゾール-5-カルボキサミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N-(エトキシカルボニルメチル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $184 \sim 186 ^{\circ} (\text{decomp.})$; IRv max cm^{-1} 3408, 2216, 1744, 162 4; NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δpp m 1. 18(3H, t), 1. $85 \sim 2$. 04(2H, m), 2. $18 \sim 2$. 30(4H, m), 3. $62 \sim 3$. 70(1H, m), 4. 13(2H, q), 4. 71(2H, brs), 7. $27 \sim 7$. 45(4H, m), 7. 51(1H, s); MS (FAB) m/z $437(M^+ + 1)$; 元素分析値 $C_{21}H_{20}N_6O_3$ Sの計算値(%) C, 57. 78; H, 4. 62; N, 19. 26, 測定値(%) C, 57. 46; H, 4. 62; N, 19. 74.

【0362】 [実施例109] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N-メチル-1H-テトラゾール-5-カルボキサミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) トリフルオロアセ タミドの合成

3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) アニリン209mg及びトリエチルアミン1mlに塩化メチレン10mlを加え、氷冷撹拌下にトリフルオロ酢酸無水物0.126mlを加えた。反応液を室温で15時間撹拌した後、1N塩酸100mlを加え。塩酸メチレンで抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製し、N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)トリフルオロアセタミド198mgを油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.9$ $9\sim2.09(2H, m), 2.27\sim2.42(4H, m), 3.70(1H, m), 6.98$ (1H, s), 7.41(1H, t), 7.4 7(1H, dt), 7.61(1H, d),7.81(1H, t), 7.93(1H, brs).

【0363】(工程2) N-3-(2-(4-シクロ プチル-2-チアゾリル)エチニル)-N-メチルアニ リンの合成

(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エ チニル)フェニル)トリフルオロアセタミド198m g、炭酸カリウム117mg及びヨウ化メチル0.04 m1にDMF5m1を加え、室温で8時間撹拌した。反 応被に1N塩酸10ml及び水100mlを加え、酢酸 エチルえ抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄後、硫酸 ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残渣に 炭酸ナトリウム120mg、水5m1及びメタノール1 5mlを加え、室温で8時間撹拌した。反応液を酢酸工 チル100mlで希釈し、飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナ トリウムで乾燥した。溶媒を留去して、N-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアソリル) エチニル) -N ーメチルアニリン130mgを黄色針状晶として得た。 融点73~75℃; NMR (400MHz, CDC1 $_3$) δppm 1. 87~2. 10 (2H, m), 2. $26\sim2$. 40 (4H, m), 2. 83 (3 H, s), 3.69 (1H, m), 6.63 (1H, d), 6.80 (1H, t), 6.9 2 (1H, s), 6.93 (1H, d), 7. 16 (1H, t).

【0364】(工程3) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-N-メチル-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-カルボキサミドの合成

N-3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -N-メチルアニリンと参考例21のカルボン酸を実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3 -(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N-メチル-2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサミドを淡黄色油状物として得た。

NMR $(400 \, \text{MHz}, \, \text{CDCl}_3) \, \delta \, \text{ppm} \, 1.9 \, 1 \sim 2.09 \, (2 \, \text{H}, \, \text{m}) \, , \, 2.28 \sim 2.39 \, (4 \, \text{H}, \, \text{m}) \, , \, 3.50 \, (3 \, \text{H}, \, \text{s}) \, , \, 3.65 \sim 3.73 \, (1 \, \text{H}, \, \text{m}) \, , \, 3.75 \, (3 \, \text{H}, \, \text{s}) \, , \, 5.54 \, (2 \, \text{H}, \, \text{s}) \, , \, 6.82 \, (2 \, \text{H}, \, \text{d}) \, , \, 6.97 \, (1 \, \text{H}, \, \text{s}) \, , \, 7.08 \sim 7.1 \, 0 \, (3 \, \text{H}, \, \text{m}) \, , \, 7.20 \sim 7.21 \, (1 \, \text{H}, \, \text{m}) \, , \, 7.34 \, (1 \, \text{H}, \, \text{s}) \, , \, 7.42 \, (1 \, \text{H}, \, \text{d}) \, .$

【0365】(工程4) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-N-メチル-1H-テトラゾール-5-カルボキサミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-N-メチル-2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-カルボキサミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $229\sim230$ $^{\circ}$ (decomp.); IR ν max cm^{-1} 3404, 2216, 1618; NMR $(400MHz, DMSO-d_6)$ δ ppm 1.86 \sim 2.01(2H, m), 2.17 \sim 2.30(4H, m), 3.42(3H, s), 3.61 \sim 3.70(1H, m), 7.23(1H, d), 7.34(1H, t), 7.43(1H, d), 7.46(1H, s), 7.51(1H, s); MS (FAB) m/z 365 $(M^+$ + 1); 元素分析値 $C_{18}H_{16}N_6$ OSの計算値(%) C, 59.32; H, 4.43; N, 23.07, 測定値(%) C, 58.89; H, 4.27; N, 22.78.

【0366】 [実施例110] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1H-[1, 2, 3] トリアゾール:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2 -チアゾリル) エチニル) フェニル) プロピオルアミド の合成

3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) アニリンとプロピオル酸を実施例103の工程1 と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) プロピオルアミドを得た。

融点 158~160℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーエーテル); NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.88~2.10 (2H, m), 2.27 ~2.42 (4H, m), 2.99 (1H,

s), 3.70 (1H, m), 6.97 (1H, s), 7.34 (1H, t), 7.36 (1 H, dd), 7.59(1H, dd), 7.7 5 (1H, s), 7.77 (1H, br s). 【0367】(工程2) N-(3-(2-(4-シク ロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -1 H-[1, 2, 3] トリアゾールの合成 N- (3- (2- (4-シクロプチル-2-チアゾリ ル) エチニル) フェニル) プロピオルアミドを実施例7 7の工程1と同様に処理し、表題物を得た。 融点 259~262℃ (再結晶溶媒:エタノールーエ ーテル); NMR (400MHz, DMSO-dg) $\delta ppm = 1.87 \sim 2.05 (2H, m), 2.1$ $9\sim2.31$ (4H, m), 3.67 (1H, m), 7.38(1H, d), 7.46(1H, t), 7.53(1H, s), 7.92(1 H, d), 8.16(1H, s), 8.59 (1H, brs), 10.62 (1H, s); MS(EI) m/z 341 (M⁺); 元素分析値C 18H₁₅N₅ OS・1/2H₂ Oの計算値(%) C, 6 0.32; H, 4.50; N, 19.54, 測定 值(%) C, 60.58; H, 4.31; N, 1 9.16.

【0368】 [実施例111] N-(3-(2-(4 ーシクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ ル) マレインアミド酸: 3-(2-(4-シクロブチル -2-チアゾリル) エチニル) アニリン274mg及び 無木マレイン酸106mgにトルエン5ml及びTHF 2m1を加え、2時間加熱還流した。冷却して得られる 結晶を集め、クロロホルムーエタノールーnーヘキサン から再結晶し、表題物を黄色微細針状晶として得た。 融点 170~172℃ (decomp.); IRv $\max \ cm^{-1} \ 3412, 2216, 1708, 162$ 8; NMR (400MHz, DMSO- d^6) δpp m 1. $84\sim2$. 09 (2H, m), 2. $19\sim$ 2. 33 (4H, m), 3. 67 (1H, m), 6.32 (1H, d), 6.50 (1H, d), 7. 37 (1H, d), 7. 44 (1H, t), 7.53 (1H, s), 7.63 (1H, d), 7.98 (1H, s), 10.53 (1 H, s), 12.96 (1H, s); MS (E I) m/z 353 (M^+) .

【0369】 [実施例112] 2-N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミノカルボニル-1-シクロヘキセン-1-カルボン酸:3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンと3,4,5,6-テトラヒドロ無水フタル酸を実施例111と同様に処理し、表題物を得た。

融点 139~141℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー

 $n- \sim + + \nu$); IR ν max c m⁻¹ 3300,29 44,2216,1718,1662,1640,1606; NMR (400MHz,DMSO-d₆) δ p p m 1.63(4H,s),1.83~2.08(2H,m),2.20~2.33(8H,m),3.62~3.70(1H,m),7.31(1H,d),7.39(1H,d),7.52(1H,s),7.59(1H,d),7.96(1H,s),10.17(1H,s),12.46(1H,brs);MS(FAB) m/z 407(M⁺+1);元素分析値C₂₃H₂₂N₂O₃S·1/4H₂Oの計算値(%)C,67.21;H,5.52;N,6.82,測定値(%)C,67.15;H,5.40;N,6.89.

【0370】 [実施例113] 2-N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミノカルボニル-1-シクロプロパンカルボン酸:

(工程1) メチル 2-(N-(3-(2-(4-シ クロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) ア ミノカルボニル) -1-シクロプロパンカルボキシレー トの合成

3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) アニリンと2-メトキシカルボニルー1-シクロプロパンカルボン酸を実施例103の工程1と同様に処理し、メチル 2-(N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)) エチニル) フェニル) アミノカルボニル) -1-シクロプロパンカルボキシレートを淡黄色油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.4$ $2\sim1.45 (1H, m), 1.70\sim1.80 (1H, m), 1.91\sim2.09 (4H, m),$ $2.11\sim2.38 (4H, m), 3.69 (1H, m), 3.75 (3H, s), 6.95 (1H, s), 7.27\sim7.30 (2H, m), 7.60 (1H, d), 7.72 (1H, s), 8.56 (1H, s).$

【0371】(工程2) 2-(N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)アミノカルボニル)-1-シクロプロパンカルボン酸の合成

メチル 2-N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) アミノカルボニル ー1-シクロプロパンカルボキシレートを実施例56と 同様に処理し、表題物を得た。

融点 177~178℃ (再結晶溶媒:エタノールーエーテル); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.18~1.23 (1H, m), 1.58~1.62 (1H, m), 1.87~2.09

(3H, m), 2.19~2.38(5H, m), 3.65(1H, m), 7.20(1H, s), 7.25(1H, t), 7.32(1H, d), 7.58(1H, d), 7.98(1H, s), 10.20(1H, s), 12.06(1H, s); 元素分析値C₂₀H₁₈N₂O₃S・1/4H₂Oの計算値(%) C, 64.76; H, 5.03; N, 7.55, 測定値(%) C, 64.92; H, 5.01; N, 7.53.

【0372】 [実施例114] $2-N-((3-(2-(4-2))^2 + (3-(2-2)^2 + (2-2)^2$

融点 170~172℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-n++\nu$); IR ν max cm⁻¹ 3320, 29 48, 2216, 1698, 1590; NMR (40 0MHz, $DMSO-d_6$) δppm 1.63 (4 H, s), 1.85 \sim 2.02(4H, m), 2. $20\sim2$. 30 (4H, m), 2. $63\sim2$. 65 (2H, m), 2.76 \sim 2.77 (2H, m), $3.62\sim3.70$ (1H, m), 7.36 (1H, d), 7.42 (1H, t), 53 (1H, s), 7.64 (1H, d), 7. 97 (1H, s), 10. 41 (1H, s), 12.69(1H, brs); 元素分析值C ₂₂H₂₀N₂ O₃ S・1/4H₂ Oの計算値(%) 66.56; H, 5.20; N, 7.06, 測定 值(%) C, 66.47; H, 4.98; N, 7. 41.

【0373】 [実施例115] (cis) -2-N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エ

チニル)フェニル)アミノカルボニルー4ーシクロヘキセン-1-カルボン酸:3-(2-(4-シクロブチル

-2- チアゾリル) エチニル) アニリンと(c i s) -4- シクロへキセン-1 、 2- ジカルボン酸無水物を実施例 1 1 と同様に処理し、表題物を得た。 融点 1 7 6 \sim 1 7 9 $^{\circ}$ (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノール- n - へキサン); IR ν max c m $^{-1}$ 3 3 2 0 、 2 9 4 0 、 2 2 1 6 , 1 7 1 0 , 1 6 8 8 ; NMR(400 MH z, DMSO $-d_6$) δ p p m 1.86 \sim 2.0 2(2 H, m), 2.18 \sim 2.2 3(4 H, m), 2.25 \sim 2.6 2(6 H, m), 2.90 \sim 2.91(1 H, m), 3.0 4 \sim 3.0 5(1 H, m), 3.6 1 \sim 3.7 0(1 H, m), 7.5 1(1 H, s), 7.5

7 (1H, d), 7.95 (1H, s), 9.

92 (1 H, s), 12.13 (1 H, s); MS (FAB) m/z 407 (M⁺ +1); 元素分析值C₂₃H₂₂N₂O₃ S·1/4H₂ Oの計算値 (%) C, 67.21; H, 5.52; N, 6.82, 測定値 (%) C, 67.26; H, 5.41; N, 6.81.

【0374】 [実施例116] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メチルマレインアミド酸:3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンとメチルマレイン酸無水物を実施例111と同様に処理し、表題物を得た。

融点 132~136℃(decomp.); IRν max cm⁻¹ 2216, 1706, 1632; NMR $(400MHz, DMSO-d_6) \delta ppm 1.83$ \sim 2.09 (2H, m), 2.00 (3H, d), $2.16\sim2.34$ (4H, m), 3.67 (1H, m), 6.11 (1H, d), 33 (1H, d), 7.42 (1H, t), 7. 53 (1H, s), 7. 62 (1H, d), 7. 97 (1H, s), 10. 33 (1H, s), 12.85 (1H, s); MS (FAB) m/z 367 (M+1); 元素分析値C20H18N ₂ O₃ S・H₂ Oの計算値(%)· C, 62.48; H, 5. 24; N, 7. 29, 測定値(%) C, 62.77; H, 4.88; N, 7.28. 【0375】 [実施例117] N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ ル) -2-フェニルマレインアミド酸:3-(2-(4 ーシクロプチルー2ーチアソリル) エチニル) アニリン とフェニルマレイン酸無水物を実施例111と同様に処 理し、表題物を得た。

融点 $172\sim175$ \mathbb{C} (decomp.); IR ν max cm $^{-1}$ 2212, 1712, 1686; NMR (400MHz, DMSO $^{-1}$ d $_{6}$) δ ppm 1.84 \sim 2.05 (2H, m), 2.19 \sim 2.33 (4H, m), 3.67 (1H, m), 6.61 (1H, d), 7.37 (1H, d), 7.4 $4\sim$ 7.55 (7H, m), 7.65 (1H, s), 8.04 (1H, s), 10.54 (1H, s), 13.20 \sim 13.23 (1H, br); MS (FAB) m/z 429 (M $^{+}$ +1); 元素分析值 $\mathbb{C}_{25}H_{20}N_2$ O $_3$ S σ 計算值 (%) \mathbb{C} , 70.07; H, 4.70; N, 6.54, 測定值 (%) \mathbb{C} , 69.70; H, 4.86; N, 6.43.

【0376】 [実施例118] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2, 3-ジクロロマレインアミド酸: 3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) アニ

リンと2,3-ジクロロマレイン酸無水物を実施例11 1と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $153\sim156$ $^{\circ}$ $^{\circ}$

【0377】 [実施例119] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2, 3-ジプロモマレインアミド酸: 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンと2, 3-ジプロモマレイン酸無水物を実施例111と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $119\sim120^{\circ}$ (decomp.); IR ν max cm $^{-1}$ 2212, 1674, 1608, 1584; NMR (400MHz, DMSO $-d_6$) δ ppm 1.84 \sim 2.05(2H, m), 2.18 \sim 2.33(4H, m), 3.67(1H, m), 7.41(1H, d), 7.46(1H, t), 7.54(1H, s), 7.59(1H, d), 7.89(1H, s), 10.86(1H, s); MS(FAB) m/z 513[(M $^+$ +4)+1), 511[(M $^+$ +2)+1)], [50 $^\circ$ 9(M $^+$)+1]; 元素分析値 $C_{19}H_{14}Br_2N_2O_3SO$ 計算値(%) C, 44.73; H, 2.77; N, 5.49, 測定値(%) C, 44.92; H, 3.13; N, 5.39.

【0378】 [実施例120] 4-N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミノカルボニル-3-カルボキシ-3-プテン酸:3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンと (cis) -アコニチン酸無水物を実施例111と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $131\sim132$ ^C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーnーへキサン); IR ν max cm $^{-1}$ 2212, 1718, 1634, 1582, 1550; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ pp m 1.84~2.05(2H, m), 2.19~2.33(4H, m), 3.32(2H, s), 3.67(1H, m), 6.46(1H,

s), 7. 36~7. 33 (1H, m), 7. 4 3 (1H, t), 7. 53 (1H, s), 7. 6 3 (1 H, d), 7.97 (1 H, s), 1 0.47 (1 H, s), 12.59 (1 H, b r), 12.96 (1 H, br); MS (FA B) m/z $411 (M^+ +1)$; 元素分析值 $C_{21}H$ $_{18}N_2O_5$ S· $1/2H_2$ Oの計算值 (%) C, 6 0.13; H, 4.57; N, 6.68, 測定值 (%) C, 60.44; H, 4.55; N, 6.68

【0379】 [実施例121] (cis) -N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1, 2-シクロヘキサンアミド酸: 3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンと (cis) -1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸無水物を実施例111と同様に処理し、表題物を得た。

融点 179~180℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー エタノールーnーヘキサン) : $IR \nu \max c m^{-1} 2$ 216, 1706, 1606, 1584, 1544; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1. $31\sim2$. 31(14H, m), 2. $60\sim$ 2. 61 (1H, m), 2. $94\sim2$. 95 (1 H, m), 3.62 \sim 3.70(1H, m), 7. 29 (1H, d), 7. 38 (1H, t), 7. 51 (1H, s), 7. 56 (1H, d), 7. 97 (1H, s), 9. 91 (1H, s), 11.95 (1H, br s); MS (F AB) m/z 409 (M++1);元素分析値C23H 24N₂O₃S・1/4H₂Oの計算値(%) C, 6 6.89; H, 5.98; N, 6.78, 測定値 (%) C, 66. 95; H, 5. 95; N, 6. 75.

【0380】 [実施例122] (trans) -N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -1, 2-シクロヘキサンアミド酸: 3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンと(trans) -1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸無水物を実施例111と同様に処理し、表題物を得た。

融点 200~201℃ (再結晶溶媒:クロロホルム); IRνmax cm⁻¹2216, 1726, 1666, 1644, 1608, 1582, 1500; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.85~2.55(16H, m), 3.62~3.70(1H, m), 7.29(1H, d), 7.38(1H, t), 7.51(1H, s), 7.58(1H, d), 7.96(1H, s), 10.13(1H, s), 12.08(1H, s); MS(FAB) m/z 409(M⁺+1); 元素分析値C₂₃H₂₄N₂O₃Sの計算値(%) C, 67.62; H, 5.92; N, 6.86, 測定

值(%) C, 67. 51; H, 5. 86; N, 6. 83.

【0381】 [実施例123] N-(3-(2-(2-ベンゾチアゾール) エチニル) フェニル) マレインアミド酸:3-(2-(2-ベンゾチアゾール) エチニル) アニリンと無水マレイン酸を実施例111と同様に処理し、表題物を得た。

融点 169~171℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノール); IRνmax cm⁻¹ 2212, 1702, 1628, 1554; NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 6.33 (1H, d), 6.50 (1H, d), 7.44~7.50 (2H, m), 7.68 (1H, d), 8.05~8.10 (2H, m), 8.18 (1H, s), 10.57 (1H, s), 12.95 (1H, s); MS (FAB) m/z 349 (M++1). 【0382】 [実施例124] (Z) -N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-(1H-テトラゾール-5-イル) シンナムアミド:

(工程1) 2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-カルバルデヒドの合成

参考例19のカルボン酸16gをエタノール100mlに溶解し、0℃で撹拌下に水素化ホウ素ナトリウム3.57gを徐々に加えた。反応液を室温で12時間撹拌した後、氷水100mlを加え、シュウ酸を加えて中和した。これを塩化メチレンで抽出し、抽出液を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去して得られた油状物を、精製することなくトルエン100ml及び活性二酸化マンガン15.3gを加え、3時間加熱還流した。冷却後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:nーへキサン:酢酸エチル=4:1)で精製し、2ー(4ーメトキシベンジル)−2H−テトラゾール−5ーカルバルデヒド4.5gを淡黄色油状物として得た。

IR ν max cm⁻¹ 1726; NMR (400MH z, CDCl₃) δ ppm3.80 (3H, s), 5.79 (2H, s), 6.91 (2H, dt), 7.39 (2H, dt), 10.19 (1H, s).

【0383】(工程2) 2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾリル)フェニルメタノールの Art

2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー 5-カルバルデヒド910mgをTHF20mlに溶解 し、0℃で撹拌下にフェニルマグネシウム プロミド (1MのTHF溶液)5mlを加えた。反応液を同温度 で1時間撹拌した後、飽和塩化アンモニウム水溶液30 mlを加えた。混合液を酢酸エチルで抽出し、抽出層を 飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶 媒を留去して得らる残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製し、2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニルメタノール916mgを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 3.0 1 (1H, br s), 3.79 (3H, s), 5.65 and 5.67 (2H, each d), 6.11 (1H, d), 6.88 (2H, dt), 7.25~7.48 (7H, m). 【0384】(工程3) 5-ペンゾイルー2ー(4ーメトキシベンジル)ー2Hーテトラゾールの合成2ー(2ー(4ーメトキシベンジル)ー2Hーテトラゾールー5ーイル)フェニルメタノールを工程1と同様に活性二酸化マンガンで酸化し、5ーベンゾイルー2ー(4ーメトキシベンジル)ー2Hーテトラゾールを得た。

融点61~62℃; NMR (400MHz, CDC1₃) δ p p m 3.80 (3H, s), 5.82 (2H, s), 6.91 (2H, d), 7.42 (2H, dt), 7.53 (2H, t), 7.67 (1H, t), 8.34 (2H, d). 【0385】(工程4) (Z) -エチル 3-(2-(4-メトキシベンジル) - 2H-テトラゾールー5-イル) 桂皮酸の合成

水素化ナトリウム(60%油性)148mgをTHF15mlに懸濁し、0℃でトリエチル フォスフォノ酢酸832mgを加え、1時間撹拌した。反応液に、0℃で5ーベンゾイルー2ー(4ーメトキシベンジル)ー2Hーテトラゾール909mgTHF5ml溶液を加え、さらに同温度で1時間撹拌した。反応液に水30mlを加え、酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:nーヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製し、(Z)ーエチル 3ー(2ー(4ーメトキシベンジル)ー2Hーテトラゾールー5ーイル)桂皮酸900mgを油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.0$ 5 (3H, t), 3.76 (3H, s), 4.01 (2H, q), 5.77 (2H, s),6.62 (1H, s), 6.89 (2H, d),7.29~7.49 (7H, m).

【0386】(工程5) (Z)-3-(2-(4-メ トキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) 桂 皮酸の合成

(Z) -エチル 3-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) 桂皮酸を実施例56 と同様に処理し、(Z) -3-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) 桂皮酸を得 た。

融点 126℃; IRvmax cm⁻¹ 2596, 17 12; NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 3. 79 (3H, s), 5. 76 (2H, s), 6. 62 (1H, s), 6. 89 (2H, d), 7. $27 \sim 7$. 54 (7H, m); MS (FAB) m/z 336 (M+1); 元素分析值 C₁₈H₁₆N₄O₃の計算値(%) C, 64.28; H, 4. 79; N, 16. 66, 測定値(%) C, 64.02; H, 4.93; N, 16.61. 【0387】 (Z) -N- (3-(2-(4-シクロブ チルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール -5-イル) シンナムアミドの合成 3- (2-(2-ベンゾチアゾール) エチニル) アニリ ンと(Z)-3-(2-(4-メトキシベンジル)-2 H-テトラゾール-5-イル) 桂皮酸を実施例103の 工程1と同様に処理し、(Z)-N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニ ル) -3- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テ トラゾールー5-イル)シンナムアミドを淡黄色油状物 として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.8 9~2.41 (6H, m), 3.70 (1H, m), 3.76 (3H, s), 5.74 (2H, s), 6.74 (1H, s), 6.82 (2 H, d), 6.96 (1H, s), 7.27~ 7.40 (9H, m), 7.55 (1H, d), 7.76 (1H, s), 7.96 (1H, s). 【0388】 (工程7) (Z) -N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-(1H-テトラゾール-5-イル) シンナムアミドの合成

(Z) -N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-3-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) シンナムアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 127~129℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); NMR (400MHz, DMSOd₆) δppm 1.85~2.33 (6H, m), 3.66 (1H, m), 7.14 (1H, s), 7.30~7.59 (8H, m), 7.93 (1 H, s), 10.69 (1H, s); MS (F AB) m/z 453 (M⁺+1).

【0389】 [実施例125] (E) -N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-3-(1H-テトラゾール-5-イル) プロペンアミド:

(工程1) (E) -エチル 2-フルオロー3-(2

- (4-メトキシベンジル) - 2H-テトラゾール-5 -イル) アクリル酸の合成

2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー 5-カルバルデヒドとトリエチル 2-フルオロフォノ 酢酸を実施例 <math>124の工程 4と同様に処理し、(E) - エチル 2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)プロペンアミドを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 1. 1 6 (3H, t), 3. 80 (3H, s), 4. 22 (2H, q), 5. 70 (2H, s), 6. 73 (1H, d), 6. 89 (2H, d), 7. 34 (2H, d).

【0390】(工程2) (E) -2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール -5-イル) アクリル酸の合成

エチル (E) -2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) アクリル酸を実施例 56 と同様に処理し、(E) -2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) アクリル酸を得た。

融点 65℃; IR v max c m ⁻¹ 2952, 284 4, 2728, 2616, 2532, 1750; NM R (400MHz, CDCl₃) δ p p m 3.82 (3H, s), 5.77(2H, s), 6.9 3(2H, d), 7.00(1H, d), 7.3 8(2H, d); 元素分析値C₁₂H₁₁FN₄O₃の計算値(%) C, 51.80; H, 3.98; N, 20.14, 測定値(%) C, 51.92; H, 4.09; N, 20.22.

【0391】(工程3) (E) -N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) プロペンアミドの合成

3-(2-(2-ベンゾチアゾール) エチニル) アニリンと(E) -2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル) -2 H-テトラゾール-5-イル) アクリル酸を実施例103の工程1と同様に処理し、(E) -N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル) -2 H-テトラゾール-5-イル) プロペンアミドを淡黄色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.9 0~2.42(6H, m), 3.70(1H, m), 3.80(3H, s), 5.78(2H, s), 6.90~7.00(4H, m), 7. 35~7.41(4H, m), 7.84(1H, dt), 7.95(1H, s), 11.74(1

H, s).

【0392】(工程4) (E)-N-(3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) フェ ニル) -2-フルオロ-3-(1H-テトラゾール-5 ーイル) プロペンアミドの合成 (E) $-N-(3-(2-(4-\nu)))$ アソリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール -5-イル)プロペンアミドを実施例1の工程5と同様 に処理し、表題物を得た。 融点 211~212℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-(3+3); IR $\nu \max cm^{-1}$ 2212, 16 72; NMR $(400MHz, DMSO-d_6) \delta p$ pm 1. $84\sim2$. 33 (6H, m), 3. 67 (1H, m), 7.23 (1H, d), ~ 7.54 (3H, m), 7.74 (1H, d), 8.07(1H, s), 11.14(1 H, s); MS (FAB) m/z 395 (M^+ + 1); 元素分析値C₁₉H₁₅FN₆ OS・1/2H₂ O の計算値(%) C, 56.57; H, 4.00; N, 20.83, 測定値(%) C, 56.37; H, 3. 87; N, 20. 67. 【0393】[実施例126] (Z)-N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニ ル)フェニル) -2-フルオロ-3-(1H-テトラゾ ールー5ーイル)プロペンアミド: (工程1) (Z) -N-(3-(2-(4-シクロブ チルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フ ルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) プロペンアミドの合成 実施例125の工程3で2-異性体を分離し、(2)- $N - (3 - (2 - (4 - \nu) / 2 - \tau)^{-1})$ ル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) プロペンアミドを淡黄色油状物として得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.9 $2\sim2.44$ (6H, m), 3.70 (1H, m), 3.81 (3H, s), 5.75 (2H, 6. 91 (2H, d), 6. 97 (1 H, s), 7.35 \sim 7.43(4H, m), 7. 68 (1H, m), 7. 87 (1H, d), 8. 10 (1H, m). 【0394】(工程2) (Z)-N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) フェ ニル) -2-フルオロ-3- (1H-テトラゾール-5 ーイル) プロペンアミドの合成 (Z) -N- (3-(2-(4-シクロブチル-2-チ アゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール -5-イル)プロペンアミドを実施例1の工程5と同様

に処理し、表題物を得た。

融点125~128℃; 元素分析値C₁₉H₁₅FN₆O S・1/2H₂ Oの計算値(%) C, 56.57; H, 4.00; N, 20.83, 測定値(%) C, 56.86; H, 4.29; N, 20.00. 【0395】 [実施例127] (E) -N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニ ル)フェニル) -2-フルオロ-3- (1H-テトラゾ ールー5ーイル) -2ープテンアミド: (工程1) 1-(2-(4-メトキシベンジル)-2 H-テトラゾール-5-イル) エタノールの合成 2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールー 5-カルバルデヒドとメチルマグネシウムプロミド(3 Mのエーテル溶液)を実施例124の工程2と同様に処 理し、1-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テ トラゾール-5-イル) エタノールを得た。 融点61~62℃; NMR (400MHz, CDC1. 3) δppm 1.65 (3H, d), 2.56 (1H, d), 3.80 (3H, s), 5.1 6 (1H, m), 5.67 (2H, s), 6. 89 (2H, dt), 7.34 (2H, dt). 【0396】(工程2) 2-アセチル-2-(4-メ トキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成 1-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾ ールー5ーイル) エタノールを実施例124の工程3と 同様に処理し、2-アセチル-2-(4-メトキシベン ジル) -2H-テトラゾールを得た。 融点 66~67℃; IRvmax cm⁻¹ 1718; NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 2$. 74 (3H, s), 3.80 (3H, s), 5. 77 (2H, s), 6. 90 (2H, d), 7. 39 (2H, d). 【0397】(工程3) エチル (E)-2-フルオ ロ-3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テト ラゾールー5ーイル) -2-ブテン酸の合成 2-アセチル-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールを実施例125の工程1と同様に処理し、 エチル (E) -2-フルオロ-3-(2-(4-メト キシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2 -ブテン酸を油状物として得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.0 0 (3H, t), 2.17 (3H, d), 80 (3H, s), 4.04 (2H, q), 5. 70 (2H, s), 6. 90 (2H, d), 7. 36 (2H, d). 【0398】(工程4) (E)-2-フルオロー3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール -5-イル) -2-ブテン酸の合成 エチル (E) -2-フルオロ-3-(2-(4-メト キシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2 ープテン酸を実施例56と同様に処理し、(E)-2フルオロ-3-(2-(4-)++)ジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-ブテン酸を油状物と して得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 2. 3 6 (3H, d), 3. 81 (3H, s), 5. 76 (2H, s), 6. 93 (2H, d), 7. 38 (2H, d).

【0399】(工程5) (E) -N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-プテンアミドの合成

3-(2-(2-ベンゾチアゾール) エチニル) アニリンと (E) -2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル) -2 H- テトラゾール-5-イル) ブテン酸を実施例103 の工程1 と同様に処理し、(E) - N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-3-(2-(4-メトキシベンジル) -2 H- テトラゾール-5-イル) ブテンアミドを淡黄色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.8 9~2.39 (6H, m), 3.69 (1H, m), 3.78 (3H, s), 5.74 (2H, s), 6.89 (2H, dt), 7.29~ 7.40 (4H, m), 7.59 (1H, d), 7.81 (1H, s), 9.24 (1H,

【0400】(工程6) (E) -N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェ ニル)-2-フルオロ-3-(1H-テトラゾール-5 -イル)ブテンアミドの合成

s).

(E) $-N-(3-(2-(4-\nu)01) + N-(2-4) - N-(3-(2-(4-\nu)01) + N-(2-1) + N-(2-(4-\lambda) + N-(2-1) + N-(2-1$

融点 $199\sim200$ °C; IR ν max c m⁻¹ 2216, 1672; NMR (400MHz, DMSO-d6) δ p p m 1.88 \sim 2.27 (6H, m), 3.66 (1H, m), 7.42 \sim 7.47 (2H, m), 7.52 (1H, s), 7.68 (1H, d), 7.93 (1H, s), 10.74 (1H, s); MS (FAB) m/z 409 (M⁺+1);元素分析值C₂₀H₁₇FN₆ OS·3/4H₂ Oの計算值(%) C, 56.93; H, 4.42; N, 19.92, 測定値(%) C, 57.13; H, 4.18; N, 19.80.

【0401】 [実施例128] (E) -N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-(1H-テトラゾール-5-イ

ル) -2-プロペンアミド:

クリル酸の合成

(工程1) エチル (E) -3-(2-(4-)) トキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) アクリル酸の合成

2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー 5-カルバルデヒドとトリエチル フォノ酢酸を実施例 <math>124の工程 4 と同様に処理し、エチル (E)-3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール <math>-5 - 4 ー

融点36℃; NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1. 33 (3H, t), 3. 80 (3H, s), 4. 27 (2H, q), 5. 70 (2H, s), 6. 90 (2H, dt), 7. 35 (2H, dt), 7. 66 (1H, d). 【0402】(工程2) (E) -3-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ア

エチル (E) -3-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) アクリル酸を実施例 56 と同様に処理し、(E) -3-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) アクリル酸を得た。

融点 $167\sim169$ C; $IRvmax cm^{-1} 26888, 2268, 2556, 1694; NMR (400MHz, CDCl₃) <math>\delta$ ppm 3.80 (3H, s), 5.71 (2H, s), 6.90 (2H, d), 7.36 (2H, dt), 7.76 (1H, d); MS (FAB) m/z 261 (M⁺+1); 元素分析値 $C_{12}H_{12}N_4O_3$ の計算値 (%) C,55.38; H,4.65; N,21.53, 測定値 (%) C,55.34; H,4.70; N,21.63.

【0403】(工程3) (E) -N-(3-(2-(4-)2-2)) (4-(2-2)) (4-(2-2)) (2-(4-)) (2-(4-)) (2-(4-)) (2-(4-)) (E) -(4-)) (2-(4-)) (E) -(4-)) (2-(4-)) (3-(2-)) (4-(4-)) (2-(4-)) (3-(2-)) (4-(4-)) (2-(4-)) (3-(4-)) (2-(4-)) (3-(4-)) (3-(4-)) (3-(4-)) (4-(4-)) (4-(4-)) (5-(4-)) (6-(4-)) (7-(4-)) (8-(4-)) (

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.9$ $4\sim2.36(6H, m), 3.70(1H, m), 3.81(3H, s), 5.71(2H, s), 6.96(1H, s), 7.14(2H, d), 7.34(4H, m), 7.40$ <math>(1H, m), 7.77(1H, d), 7.83 (1H, s).

【0404】(工程4) (E) -N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-(1H-テトラゾール-5-イル) -2-プロペンアミドの合成

(E) -N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-プロペンアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 >300°C; IR ν max c m⁻¹ 2212, 1674; NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 1.84 \sim 2.31 (6H, m), 3.67 (1H, m), 7.30 \sim 7.59 (5H,

m), 7.71 (1H, d), 8.09 (1H, s), 10.75 (1H, s); MS (FAB) m/z 377 (M^+ +1); 元素分析值 C_{19} H₁₆N₆OS·1/2H₂Oの計算値 (%) C, 59.21; H, 4.45; N, 21.80, 測定値 (%) C, 59.03; H, 4.29; N, 21.66.

【0405】 [実施例129] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(1H-テトラゾール-5-イル) -1-シクロペンテン-1-カルボキサミド:

(工程1) エチル 2-(2-(4-)++シベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-1-シクロペンテン-1-カルボキシレートの合成

エチル 2-シアノ-1-シクロペンテン-1-カルボキシレートを参考例20と同様に処理し、エチル 2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-1-シクロペンテン-1-カルボキシレートを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p.pm 1. 1 3 (3H, t), 2.05 (2H, q), 2. 85 (2H, t), 2.96 (2H, t), 3.79 (3H, s), 4.15 (2H, q), 5.68 (2H, s), 6.86 (2H, d), 7,32 (2H, d).

【0406】 (工程2) 2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-1-シクロベンテン-1-カルボン酸の合成

エチル 2-(2-(4-)++)ジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-1-シクロペンテン-1-カルボキシレートを実施例56と同様に処理し、2-(2-(4-)++)ジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-1-シクロペンテン-1-カルボン酸を得た。

融点 $106\sim108$ °C; NMR (400MHz, CD Cl₃) δ ppm 1.99 (2H, q), 2.9

3~3.03(2H, m), 3.10~3.33(2H, m), 3.80(3H, s), 5.7 1(2H, s), 6.91(2H, d), 7,3 7(2H, d); 元素分析値C₁₅H₁₆N₄O₃の計算値(%) C,59.99; H,5.37; N,1 8.66, 測定値(%) C,59.69; H,5.

【0407】(工程3) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-1-シクロペンテン-1-カルボキサミドの合成

2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)-1-シクロへペンテン-1-カルボン酸と3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル)エチニル)アニリンを実施例<math>103の工程1と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-1-シクロペンテン-1-カルボキサミドを淡黄色油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.8 ~2.11 (2H, m), 2.28~2.41 (4H, m), 3.08 (2H, t), 3.16 (2H, t), 3.68 (1H, m), 3.7 9 (3H, s), 5.76 (2H, s), 6.9 0 (2H, d), 6.95 (1H, s), 7, 29~7.33 (2H, m), 7.37 (2H, d), 7.78~7.81 (1H, m), 7.9 6 (1H, s), 11.58 (1H, s). 【0408】(工程4) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(1H-テトラゾール-5-イル)-1-シクロペンテン-1-カルボキサミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(2-(4-メトキシベンジル) -2 H-テトラゾール-5-イル) -1-シクロペンテン-1-カルボキサミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $186 \sim 189 ^{\circ} \text{C} (\text{decomp.})$; NMR $(400 \text{MHz}, \text{DMSO} - \text{d}_6) \delta \text{ppm} 1.81$ $\sim 2.09 (2 \text{H}, \text{m}), 2.21 \sim 2.28 (4 \text{H}, \text{m}), 2.94 \sim 2.99 (4 \text{H}, \text{m}), 3.67 (1 \text{H}, \text{m}), 7.38 (1 \text{H}, \text{d}), 7.44 (1 \text{H}, \text{t}), 7.53 (1 \text{H}, \text{s}), 7.67 (1 \text{H}, \text{d}), 8.02 (1 \text{H}, \text{s}), 10.46 (1 \text{H}, \text{s}), 7.30 \sim 7.59 (5 \text{H}, \text{m}), 7.71 (1 \text{H}, \text{d}), 8.09 (1 \text{H}, \text{s}), 10.75 (1 \text{H}, \text{s}); 元素分析値<math>C_{22}H_{20}N_6 \text{OS} \cdot 1/4H_2 \text{O}$ の計算値

(%) C, 62.76; H, 4.91; N, 1 9.96, 測定値(%) C, 62.56; H, 5.04; N, 19.53.

【0409】 [実施例130] (E, E) -N-(3 -(2-(4-イソプロピル-2-チアゾリル) エチニ ル) フェニル) -5-(1H-テトラゾール-5-イ ル) -2, 4-ペンタジエナミド:

融点 $150\sim151$ °C; $IRvmax cm^{-1} 221$ 2, 1678; $NMR (400MHz, CDCl_3)$ $\delta ppm 1.35 (6H, d), 3.15 (1H, m), 3.80 (3H, s), 5.69 (2H, s), 6.90 (2H, d), 6.9 4 (1H, s), 6.95 (1H, d), 7.18<math>\sim$ 7.68 (8H, m), 7.79 (1H, br s); $MS (FAB) m/z 511 (M^+ + 1)$; 元素分析值 $C_{28}H_{26}N_6 O_2S$ の計算值 (%) C, 65.86; H, 5.13; N, 16.46, 測定值 (%) C, 65.60; H, 5.1

 (E, E) -N-(3-(2-(4-イソプロピル-2 -チアゾリル) エチニル) フェニル) -5-(2-(4 -メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2, 4-ペンタジエナミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 212~214°C(再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); NMR(400MHz, DMSO-d。)δppm 1.27(6H, d), 3.08(1H, m), 6.54(1H, d), 7.22(1H, d), 7.36~7.54(5H, m), 7.69(1H, d), 8.07(1H, s), 10.46(1H, s); 元素分析値C20H₁₈N₆OSの計算値(%) C, 61.52; H, 4.65; N, 21.52, 測定値(%)

C, 61.50; H, 4.73; N, 21.52. 【0411】 [実施例131] 3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンゾイル-1 H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオドベンゾイル)-1-(4 -メトキシベンジル) -1H-テトラゾールの合成 3-イオド-N-メトキシ-N-メチルベンズアミド5 82mg及び1-(4-メトキシベンジル)-1H-テ トラゾール380mgにTHF10ml及びN, N'-テトラメチルエチレンジアミン1m1を加え、撹拌下一 78℃でリチウム ヘキサメチルジシラジド (1MのT HF溶液) 2mlを、5分間を要して滴下した。反応液 を、さらに同温度で30分撹拌した後、飽和塩化アンモ ニウム10mlを加え、室温に戻した。反応液を酢酸エ チルで抽出し、抽出液を飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナト リウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残渣をシリ カゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:n ーヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製し、5-(3 ーイオドベンゾイル) -1- (4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾールを得た。

融点 $86\sim89$ °C; NMR (400MHz, CDC13) δ ppm 3.76(3H, s), 5.88 (2H, s), 6.83 \sim 6.85(2H, m), 7.27(1H, t), 7.34 \sim 7.37(2H, m), 8.00(1H, d), 8.41 (1H, d), 8.67(1H, s).

【0412】 (工程2) 5-(3-(2-(4-シ)0) ロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンゾイル) -1-(4-メトキシベンジル) -1 H-テトラゾールの合成

5-(3-4オドベンゾイル)-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾールと<math>3-(2-(4-シ)ロブチル-2-チアゾリル)エチニル)アニリンを実施例1の工程4と同様に処理し、5-(3-(2-(4-シ)2クロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンゾイル)-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾールを得た。

融点83~86℃; NMR (400MHz, CDC1₃) δppm 1.92~2.40 (6H, m),
3.66~3.76 (1H, m), 3.76 (3
H, s), 5.90 (2H, s), 6.83~
6.86 (2H, m), 6.99 (1H, s),
7.35~7.37 (2H, m), 7.55 (1
H, t), 7.87 (1H, d), 8.42 (1H, d), 8.59 (1H, s).
【0413】(工程3) 3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンゾイル-1H-テトラゾールの合成

5- (3- (2- (4-シクロプチル-2-チアゾリ ル) エチニル) ベンゾイル) -1- (4-メトキシベン ジル) -1H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $191\sim196$ C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーnーへキサン); IR ν max cm $^{-1}$ 3112, 3088, 2944, 2220, 1668, 1596, 1504; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.85 \sim 2.32 (6H, m), 3.64 \sim 3.72 (1H, m), 7.56 (1H, s), 7.75 (1H, t), 8.04 (1H, d), 8.44 (1H, d), 8.64 (1H, s); MS (EI) m/z 335 (M⁺); 元素分析値C₁₇H₁₃N₅ OSの計算値 (%) C, 60.88; H, 3.91; N, 20.88, 測定値 (%) C, 60.61; H, 3.95; N, 20.82.

【0414】 [実施例132] エチル (E) -3-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エ チニル) フェニル) -3-(1H-テトラゾール-5-イル) プロペン酸:

(工程1) エチル (E) -3-(3-(2-(4-2)-2)-3-(1-(4-3)-(1-(4-3)-3-(1-(4-3)-(1-(4-3)-3-(1-(4-3)-(4-3)-(1-(4-3)-(4-3)-(1-(4-3)-(4-2)-(4-3)-(4-2)

5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンゾイル) <math>-1-(4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾールとトリエチル フォスフォノ酢酸を実施例124の工程4と同様に処理し、エチル

(E) -3-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-3-(1-(4-メトキシベンジル) -1 H-テトラゾール-5-イル)プロペン酸を油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3)$ δppm 1. 1 5 (3H, t), 1. $84\sim2$. 39(6H, m), 3. $65\sim3$. 73(1H, m), 3. 75(3H, s), 4. 12(2H, q), 5. 07(2H, s), 6. 67(1H, s), 6. $77\sim6$. 82(2H, m), 6. 99(1H, s), 7. 19(1H, d), 7. 32(1H, s), 7. 38(1H, t), 7. 64(1H, d).

【0415】(工程2) エチル (E)-3-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3-(1H-テトラゾール-5-イル)プロペン酸の合成

エチル (E) -3-(3-(2-(4-シクロプチル -2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-3-(1-(4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾール-5-イル) プロペン酸を実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 122~124℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー

 $n- \wedge + \psi >)$; IR ν max c m $^{-1}$ 2216, 1724; NMR (400MHz, CDCl $_3$) δ p p m1.10 (3H, t), 1.86 \sim 2.37(6H, m), 3.58 \sim 3.67(1H, m), 4.07(2H, q), 6.98(1H, s), 7.23(1H, s), 7.30 \sim 7.44(4H, m); MS(EI) m/z 405(M $^+$); 元素分析値 $C_{21}H_{19}N_5$ O_2 Sの計算値(%) C, 62.21; H, 4.72; N, 17.27, 測定値(%) C, 62.06; H, 4.66; N, 17.02.

【0416】 [実施例133] 3-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-(1H-テトラゾール-5-イル) プロペン酸: エチル (E) -3-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-(1H-テトラゾール-5-イル) プロペン酸を実施例56と同様に処理し、表題物を得た。

融点 >300℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノ $-\nu$); IR ν max c m⁻¹ 2218, 1707, 1 629; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δ ppm 1.88~2.33 (6H, m), 3.6 $4\sim3.68(1H, m)$, 6.99(1H, s), 7.43 (1H, d), 7.52 (1H, t), 7.52 (1H, s), 7.61 (1 H, s), 7. 70 (1H, d); MS (FA B) m/z 378 (M⁺ +1); 元素分析値C₁₉H 15N₅ O₂ Sの計算値(%) C, 60.46; H, 4.01; N, 18.56, 測定値(%) C, 6 0. 52; H, 4. 15; N, 18. 65. 【0417】 [実施例134] (E) - 3 - (3 -(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニ ル) フェニル) -3- (1H-テトラゾール-5-イ ル) アクリロニトリル:

(工程1) (E) -3-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-(1-(4-メトキシベンジル) -1 Hーテトラゾールー5ーイル) アクリロニトリルの合成 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンゾイル) -1-(4-メトキシベンジル) -1 Hーテトラゾールとジエチル シアノメチルフォスフォン酸を実施例124の工程4と同様に処理し、(E) -3-(3-(2-(4-シクロブチル-2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -3-(1-(4ーメトキシベンジル) -1 Hーテトラゾール-5ーイル) アクリロニトリルを油状物として得た。NMR(400MHz, CDCl3) δ ppm 1.9

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.9$ $2\sim2.40 (6H, m), 3.70\sim3.76 (1H, m), 3.76 (3H, s), 5.08$ (2H, s), 6.14 (1H, s), 6.6 2~6. 79 (4H, m), 7.00 (1H, s), 7.40~7.42 (2H, m), 7.5 1 (1H, t), 7.75 (1H, d). 【0418】(工程2) (E) -3-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3-(1H-テトラゾールー5-イル)アクリロニトリルの合成

(E) -3-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-3-(1-(4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾール-5-イル) アクリロニトリルを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $179 \sim 182$ (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノールーnーへキサン); I R ν max cm⁻¹ 2220; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.83~2.32(6 H, m), 3.62~3.71(1H, m), 6.93(1H, s), 7.54(1H, s), 7.43(1H, d), 7.52(1H, t), 7.52(1H, s), 7.66(1H, t), 7.71(1H, d), 7.85(1H, d), 7.88(1H, s); MS (FAB) m/z359 (M⁺ +1); 元素分析値C₁₉H 14N₆ Sの計算値(%) C, 62.88; H, 4.03; N, 23.16, 測定値(%) C, 62.88; H, 4.03; N, 23.16, 測定値(%) C, 62.

【0419】 [実施例135] 3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミノ-1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオドフェニル) アミノ-1-(4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾール、及び、5-(3-イオドフェニル) アミノ-2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールの合成5-(3-イオドフェニル) アミノ-1H-テトラゾールを実施例1の工程3と同様に処理し、5-(3-イオドフェニル) アミノ-1-(4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾール、及び、5-(3-イオドフェニル) アミノ-2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを得た。

融点 $138\sim139$ °C; NMR (400MHz, CD Cl₃) δ ppm 3.81 (3H, s), 5.6 1 (2H, s), 6.86 (1H, s), 6.9 2 (2H, d), 7.03 (1H, t), 7.31 (1H, dd), 7.37 (1H, dd), 7.38 (2H, d), 7.83 (1H, t). 【0420】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミノー1-(4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾール、及び 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミノー2-(4-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミノー2-(4-

メトキシベンジル) - 2 H - テトラゾールの合成 上記、ヨウ素体と4 - シクロブチル-2 - エチニルチア ゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、5 - (3 - (2 - (4 - シクロプチル-2 - チアゾリル) エチニ ル)フェニル)アミノー1 - (4 - メトキシベンジル) -1 H - テトラゾール、及び 5 - (3 - (2 - (4 - シクロプチル-2 - チアゾリル) エチニル)フェニル) アミノー2 - (4 - メトキシベンジル) - 2 H - テトラ ゾールを油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.9$ $0\sim2.50(6H, m), 3.60\sim3.70(1H, m), 3.80(3H, s), 5.64$ (2H, s), 6.91(2H, d), 6.9 6(1H, s), 7.16(1H, s), 7. 21(1H, dd), 7.32(1H, t), 7.39(2H, d), 7.43(1H, d)1.90

【0421】(工程3) 3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)アミノ-1 H-テトラゾールの合成

上記の工程2で得た化合物を、実施例1の工程5と同様 に処理し、表題物を得た。

融点 133~135℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノール); NMR (400MHz, DMSO-d6) δppm 1.80~2.40(6H, m), 3.20~3.40(1H, br s), 3.60~3.80(1H, m), 7.22(1H, d), 7.42(1H, t), 7.53(1H, s), 7.86(1H, s), 10.09(1H, s); MS (FAB) m/z 323(M⁺ + 1).

【0422】 [実施例136] 5-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェノキシ) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-イオドフェノキシ)-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾールの合成5-イオド-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾール948g、3-イオドフェノール741mg及び炭酸カリウム1.24gにDMF20mlを加え、70℃で3日間撹拌した。反応液を水200mlに注ぎ、酢酸エチルで抽出した。抽出層を水洗後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得られる残渣をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィー(溶出液:クロロホルム)で精製し、5-(3-イオドフェノキシ)-1-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾールを油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 3.8$ 0 (3H, s), 5.37 (2H, s), 6. $91\sim6.87 (2H, m), 7.13 (1H, t), 7.30\sim7.34 (3H, m), 7.6$ 0 (1H, d), 7.64(1H, s). 【0423】(工程2) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェノキシ)-1-(4-メトキシベンジル)1-H-テトラゾールの合成

5- (3-イオドフェノキシ) -1- (4-メトキシベンジル) -1 H-テトラゾーと4-シクロプチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、5- (3- (2- (4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェノキシ) -1- (4-メトキシベンジル) 1-H-テトラゾールを赤褐色油状物として得た

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p pm 1.8 $9\sim2$.40 (6H, m), 3.65 ~3 .74 (1H, m), 3.81 (3H, s), 5.39 (2H, s), 6.90 ~6 .92 (2H,

m), 6.98 (1H, m), 7.32~7.3 4 (2H, m), 7.40~7,44 (2H, m), 7.48~7.50 (1H, m), 7.5 3 (1H, s).

【0424】 (工程3) 5-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェノキシ) -1H-テトラゾールの合成

5-(3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) フェノキシ) <math>-1-(4-メトキシベンジル) 1-H-テトラゾールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $161\sim163$ [°]C(再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\wedge$ キサン); $IR\nu$ max cm^{-1} 2212; N MR(400MHz,DMSO $-d_6$) δ ppm $1.83\sim2.30$ (6H, m), $3.63\sim3.71$ (1H, m), $7.48\sim7.58$ (4H, m), 7.68(1H, s); MS(EI) m/z 323(M^+); 元素分析値 $C_{16}H_{13}N_5$ OS・1/4H₂Oの計算値(%) C, 58.61; H, 4.15; N, 21.36, 測定値(%) C, 58.85; H, 4.10; N, 21.32.

【0425】 [実施例137] 5-(3-(2-(3-(2-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) エチニル) フェニル) -1H-テトラゾール:

(工程1) 5-(3-(2-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)エチニル)フェニル)-2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールの合成

ル) エチニル) フェニル) エチニル) フェニル) -2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールを黄色 油状物として得た。

NMR $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3)$ δppm 1. 9 $0\sim2.50$ (6H, m), 3. $60\sim3.80$ (1H, m), 3. 81 (3H, s), 5. 75 (2H, s), 6. 92 (2H, d), 6. 9 8 (1H, m), 7. $30\sim7.40$ (3H, m), 7. 49 (1H, t), 7. $50\sim7.6$ 0 (2H, m), 7. 60 (1H, d), 7. 77 (1H, s), 8. 12 (1H, d), 8. 32 (1H, s).

【0426】(工程2) 5-(3-(2-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)コH-テトラゾールの合成

5- (3- (2- (3- (2- (4-シクロブチル-2 -チアゾリル) エチニル) フェニル) エチニル) フェニ ル) -2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾ ールを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得 た。

融点 $106\sim108$ \mathbb{C} (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\sim$ キサン); NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ ppm 1.80 \sim 2.40(6H, m), 3.60 \sim 3.80(1H, m), 7.70(1H, s), 7.74(1H, t), 7.60 \sim 7.80(3H, m), 7.80(1H, d), 7.90(1H, s), 8.11(1H, d), 8.25(1H, s); MS (FAB) m/z 408 (M⁺+1); 元素分析値 $C_{24}H_{17}N_5$ Sの計算値(%) C,58.25; H,3.77; N,12.82, 測定値(%) C,58.51; H,3.52; N,12.82.

【0427】 [実施例138] N-(1H-テトラゾ ール-5-イル)-4-((3-(2-(4-シクロブ チル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミノス ルフォニル) ベンズアミド:

(工程1) 4-((3-(2-(4-シクロプチルー 2-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミノスルフォ ニル) 安息香酸の合成

(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリン293m及びピリジンを塩化メチレン10m1に溶解し、4-クロロスルフォニル安息香酸254mgを加え室温で1時間撹拌した。反応液に1N塩酸10m1を加え、塩酸メチレン出る抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し得られた粗結晶をクロロホルム-n-ヘキサンで再結晶し、4-((3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミノスルフ

ォニル) 安息香酸を得た。

融点 $213\sim216$ $^{\circ}$ $^{\circ}$

【0428】 (工程2) N- (1H-テトラゾールー 5-イル) -4- ((3-(2-(4-シクロブチルー 2-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミノスルフォ ニル) ベンズアミドの合成

4-((3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミノスルフォニル) 安息香酸と5-アミノ-1H-テトラゾールを、実施例86と同様に処理し、表題物を得た。

融点 203~206℃ (decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルムーエタノール-n-ヘキサン); I $R \nu \max c m^{-1}$ 2216, 1692, 1588, 15 48, 1504, 1406, 1338; NMR (40 0MHz, $DMSO-d_6$) δppm 1. $83\sim2$. 33 (6H, m), 3.66 (1H, m), 7. dt), 7.30 \sim 7.39 (3H, 26 (1H, m), 7.53 (1H, s), 7.96 (1H, d), 8.20 (1H, d), ·10.78 (1 H, s), 12.63(1H, br); MS (FAB) m/z 506 (M⁺ +1); 元素分析 値C₂₃H₂₉N₇O₃S₂計算値(%) C, 54.6 4; H, 3. 78; N, 19. 39, 測定値 (%) C, 54. 24; H, 3. 83; N, 1 8.98.

【0429】[実施例139] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンゼンスルフォンアミド:

(工程1) N-(3-イオドフェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンゼンスルフォンアミドの合成

N- (3-イオドフェニル) -4- (1H-テトラゾール-5-イル) ベンゼンスルフォンアミドを実施例1の工程3と同様に処理し、N- (3-イオドフェニル) -4- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンゼンスルフォンアミドを得た。 融点 139~140℃ (再結晶溶媒: 塩化メチレ

 ν); NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 3.80 (3H, s), 5.74 (2H, s), 6.73 (1H, s), 6.90 (2H, d), 6.95 (1H, t), 7.05 \sim 7. 07 (1H, m), 7.38 (2H, d), 7. $44\sim7.46$ (2H, m), 7.86 (2H, d), 8.23 (2H, d); MS (FAB) m /z 538 (M⁺ +1); 元素分析値C₂₁H₁₈IN ₅O₃S計算值(%) C, 46.08; H, 3.3 1; N, 12.79, 測定値(%) C, 46.8 7; H, 3. 67; N, 12. 15. 【0430】(工程2) N-(3-(2-(4-シク ロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -4 - (2-(4-メトキシベンジル) - 2H-テトラゾー ルー5-イル) ベンゼンスルフォンアミドの合成 N- (3-イオドフェニル) -4- (2- (4-メトキ シベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンゼ ンスルフォンアミドと4-シクロプチル-2-エチニル チアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エ チニル)フェニル)ー4ー(2-(4-メトキシベンジ ル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンゼンスルフ ォンアミドを得た。

融点 130~132℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); IRvmax cm⁻¹ 2216; NM R (400MHz, CDCl₃) δppm 1.88~ 2. 40 (6H, m), 3. 69 (1H, m), 3. 79 (3H, s), 5. 73 (2H, s), 6.80 (1H, br s), 6.89 (2H, d), 7.00(1H, s), 7.1 d), 7. 21 (1H, t), 4 (1H. t), 7.32 (1H, d), 7.3 9 (1H, d), 7.84 (2H, d), 8 (2H, 19 (2H, d); MS (FAB) m/z 583 (M⁺ + 1) ; 元素分析値C₃₀H₂₆N₆O₃S₂・H ₂ O計算値(%) C, 59. 99; H, 4. 70; N, 13. 99, 測定値(%) C, 59. 91; H, 4. 37; N, 13. 88.

【0431】(工程3) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンゼンスルフォンアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンゼンスルフォンアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 172~175℃ (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーnーへキサン); IR v max c m
-1 2216, 1656, 1602, 1576, 153

8, 1352; NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 1.88~2.40(6H, m), 3.69(1H, m), 3.79(3H, s), 5.73(2H, s), 6.80(1H, br s), 6.89(2H, d), 7.00(1H, s), 7.14(1H, d), 7.21(1H, t), 7.29(1H, t), 7.32(1H, d), 7.84(2H, d), 8.19(2H, d); MS(FAB) m/z 463(M⁺+1); 元素分析值C₂₂H₁₈N₆O₂S₂·1/2H₂O計算值(%) C, 56.04; H, 4.06; N, 17.82, 測定值(%) C, 56.12; H, 3.93; N, 17.94.

【0432】 [実施例140] N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル)-3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンゼンスルフォンアミド:

(工程1) N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-3-ブロモベンゼンスルフォンアミドの合成

N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル)-3-ブロモベンゼンスルフフォンアミドを実施例1の工程3と同様に処理し、<math>N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-3-プロモベンゼンスルフォンアミドを得た。

融点 190~192℃ (再結晶溶媒:塩化メチレンー n-ヘキサン); IR ν max c m⁻¹ 1614, 1516, 1348; NMR (400MHz, CDC13) δ p p m 3.79 (3 H, s), 5.71 (2 H, s), 6.71 (1 H, s), 6.89 (2 H, d), 7.18 (2 H, d), 7.30 (1 H, t), 7.37 (2 H, d), 7.67 (2 H, d), 7.97 (1 H, t), 8.03 (2 H, d); MS (FAB) m/z 501 [(M+2)+1], 499 [(M+)+1]; 元素分析値C21H18BrN5O3 S計算値(%) C,50.41; H,3.63; N,14.00, 測定値(%) C,50.73; H,3.87; N,13.99.

【0433】(工程2) N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-3 ーイオドベンゼンスルフォンアミドの合成

N- (4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-3-ブロモベンゼンスルフォンアミドを実施例19の工程2と同様に処理し、N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-3-イオドベンゼンスルフォンアミドを得た。

融点 197~201℃ (再結晶溶媒:塩化メチレン-

 $n- \wedge + \psi >$); $IRvmax\ cm^{-1}\ 1614,\ 1516,\ 1348$; $NMR\ (400MHz,\ CDCl_3)\ \delta ppm\ 3.79\ (3H,\ s),\ 5.71\ (2H,\ s),\ 6.89\ (2H,\ d),\ 7.15\ (1H,\ t),\ 7.17\ (2H,\ d),\ 7.37\ (2H,\ d),\ 7.69\ (2H,\ d),\ 7.86\ (1H,\ d),\ 8.03\ (2H,\ d),\ 8.16\ (2H,\ d);\ MS\ (EI)\ m/z 547\ (M^+)$; 元素分析値 $C_{21}H_{18}\ IN_5\ O_3\ S計算値$ (%) C,46.08; H,3.31; N,12.79, 測定値 (%) C,46.36; H,3.48; N,12.66.

【0434】(工程3) N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンゼンスルフォンアミドの合成

N- (4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-3-イオドベンゼンスルフォンアミドと4-シクロブチル-2-エチニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンゼンスルフォンアミドを得た。

融点 $167\sim169$ [°] (再結晶溶媒: クロロホルムー $n-\wedge$ キサン); $IR\nu$ max cm^{-1} 2216, 16 14, 1514, 1480, 1388, 1846; NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.89 \sim 2.40 (6H, m), 3.72 (1H, m), 3.79 (3H, s), 5.70 (2H,

s), 6.88(2H, d), 7.00(1 H, s), 7.07(1H, s), 7.21 (2H, d), 7.36(2H, d), 7.3 9(1H, t), 7.57(1H, dt), 7.72(1H, dt), 8.03(1H, t), 8.03(2H, d); MS(FAB) m /z 583(M⁺ +1); 元素分析値C₃₀H₂₆N 6O₃S₂·1/4H₂O計算値(%) C, 61.3 6; H, 4.55; N, 14.31, 測定値

【0435】(工程4) N-(4-(1H-テトラゾ ール-5-イル)-3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル)エチニル)ベンゼンスルフォンアミドの 合成

(%) C, 61. 21; H, 4. 49; N, 1

N-(4-(2-(4-)++シベンジル)-2H-テトラゾール-5-(4-)-3-(2-(4-))-3-(4-)

融点 139~142℃ (decomp.) (再結晶溶

4. 31.

【0436】 [実施例141] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) 4-(2-(4-メトキシベンジル)-2 H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸の合成 エチル 4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸を実施例56と同様 に処理し、4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H -テトラゾール-5-イル) 安息香酸を得た。

NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ p p m 3.75 (3H, s), 5.94 (2H, s), 6.96 (2H, d), 7.41 (2H, d), 8.11 (2H, d), 8.16 (2H, d); 元素分析值C₁₆H₁₄N₄ O₃ 計算值 (%) C, 6 1.93; H, 4.55; N, 18.06, 測定值 (%) C, 61.59; H, 4.56; N, 17.80.

【0437】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル) 安息香酸と3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンを実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを黄色泡状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.8$ $9\sim2.41 (6H, m), 3.70 (1H, m), 3.80 (3H, s), 5.76 (2H, s), 6.91 (2H, d), 6.96 (1H, s), 7.38\sim7.41 (4H, m), 7.71\sim7.75 (1H, br), 7.89 (1H, d), 7.97 (2H, d), 8.27 (2H, d); MS (FAB) m/z 547 (M⁺$ +1).

【0438】(工程3) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N- (3- (2- (4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4- (1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 225~227℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー メタノール); NMR (400MHz, DMSO-d ₆) δppm 1.83~2.35 (6H, m), 3. 68 (1H, m), 7. 42 (1H, 7. 50 (1H, t), 7. 53 (1H, s), 7.89 (1H, dd), 8.16 (1 H, d), 8.19(2H, d), 8.23 (2H, d), 10.58 (1H, br); MS (FAB) m/z 427 (M⁺ +1); 元素分析 值C₂₃H₁₈N₆ OS計算值(%) C, 64. 77; H, 4. 25; N, 19. 70, 測定値(%) C, 64. 64; H, 4. 33; N, 19. 47. 【0439】 [実施例142] N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニ ル) -3- (1H-テトラゾール-5-イル) ベンズア ミド:

(工程1) 3-(2-(4-)+キシベンジル)-2 H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸の合成 エチル 3-(2-(4-)+キシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸を実施例 56 と同様 に処理し、3-(2-(4-)+キシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸を得た。

NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ p p m 3. 75 (3H, s), 5. 92 (2H, s), 6. 97 (2H, d), 7. 41 (2H, d), 7. 69 (1H, t), 8. 08 (1H, d), 8. 27 (1H, d), 8. 58 (1H, s).

【0440】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

3- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾールー5-イル) 安息香酸と3- (2- (4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) アニリンを実施例104の工程2と同様に処理し、N- (3- (2- (4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを得た。

融点140~142℃; NMR (400MHz, CD Cl₃) δppm 1.92~2.39 (6H,

m), 3.69(1H, m), 3.80(3H, s), 5.75(2H, s), 6.91(2H, d), 6.95(1H, s), 7.35~7.41(4H, m), 7.61(1H, t), 7.73(1H, m), 7.92(1H, s), 8.02(1H, d), 8.07(1H, s), 8.31(1H, d), 8.57(1H, s).

【0441】(工程3) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-3-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

【0442】 [実施例143] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N-(4-(2-(4-メトキシベンジル) テトラゾール-5-イル) ベンゾイル) グリシン:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N-(4-(2-イーメトキシベンジル) テトラゾール-5-イル) ベンゾイル) グリシン エチル エステルの合成 3-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸とN-(4-(2-(4-メトキシベンジル) テトラゾール-5-イル) ベンゾイル) グリシン エチル エステルを実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N-(4-(2-(4-メトキシベンジル) テトラゾール-5-イル) ベンゾイル) グリシン エチル エステルを油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.3$ $1 (3H, t), 1.88\sim 2.41 (6H, m), 3.68 (1H, m), 3.78 (3H, s), 4.26 (2H, q), 4.60 (2H, s), 5.70 (2H, s), 6.86 \sim$ 6.90 (2H, m), 6.96 (1H, s), 7. 11 (1H, d), 7. 18 (1H, t), 7. 34~7. 38 (3H, m), 7. 44~7. 46 (3H, m), 7. 97 (1·H, d). 【0443】 (工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)テトラゾールー5-イル)ベンゾイル)グリシンの合成N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)テトラゾールー5-イル)ベンゾイル)グリシン エチル エステルを実施例56と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $94 \sim 96 \,^{\circ}$ C; NMR $(400 \,^{\circ}$ MHz, DMS $O-d_6$) δ p p m 1.83 \sim 2.32 $(6 \,^{\circ}$ H, m), 3.65 $(1 \,^{\circ}$ H, m), 3.73 $(3 \,^{\circ}$ H, s), 4.57 $(2 \,^{\circ}$ H, s), 5.88 $(2 \,^{\circ}$ H, s), 6.94 $(2 \,^{\circ}$ H, d), 7.22 $(1 \,^{\circ}$ H, d), 7.31 $(1 \,^{\circ}$ H, t), 7.36 $(2 \,^{\circ}$ H, d), 7.43 \sim 7.47 $(3 \,^{\circ}$ H, m), 7.53 $(1 \,^{\circ}$ H, s), 7.57 $(1 \,^{\circ}$ H, s), 7.92 $(2 \,^{\circ}$ H, d), 12.96 $(1 \,^{\circ}$ H, s).

【0444】 [実施例144] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンゾイル) グリシン エチルエステル: N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリ

N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-N-(4-(2-(4-メトキシベンジル) テトラゾール-5-イル) ベンゾイル) グリシン エチル エステルを実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $89 \sim 91$ °C; IR ν max c m⁻¹ 2216, 1746, 1660; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ p p m 1.30(3H, s), 1.83 \sim 2.32(6H, m), 3.66(1H, m), 4.17(2H, q), 4.67(2H, s), 7.26(1H, d), 7.34(1H, t), 7.47(1H, d), 7.52 \sim 7.53(3H, m), 7.61(1H, s), 7.93(2H, d); MS (FAB) m/z 513(M⁺+1).

【0445】 [実施例145] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンゾイル) グリシン:

N- (3- (2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N- (4- (1H-テトラゾール-5-イル) ベンゾイル) グリシン エチルエステルを実施例56と同様に処理し、表題物を得た。
融点 135~138℃; IR vmax c m⁻¹ 221

6, 1738, 1656; NMR (400MHz, DM $SO-d_6$) $\delta p pm$ 1. $86\sim2$. 33 (6H, m), 3. 65 (1H, m), 4. 58 (2H, s), 7. 26 (1H, d), 7. 33 (1H, t), 7. 46 (1H, d), 7. 52 (1H, s), 7. 52 (2H, d), 7. 59 (1H, s), 7. 93 (2H, d), 12. 95 (1H, s); MS (FAB) m/z 485 (M^+ +1).

【0446】 [実施例146] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N-メチル-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

 (工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -N-メチル-4 -(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾー ル-5-イル) ベンズアミドの合成

3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) -N-メチルーアニリンと4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル) 安息香酸を実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N-メチルー4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル) ベンズアミドを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.8 $8\sim$ 2.41 (6H, m), 3.51 (3H,

s), 3.68(1H, m), 3.78(3H, s), 5.69(2H, s), 6.88(2H, d), 6.96(1H, s), 6.99(1H, d), 7.18(1H, t), 7.34 ~7.38(4H, m), 7.41(2H, d), 7.97(2H, d).

【0447】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-N-メチル-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N-メチル-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $126\sim128$ \mathbb{C} (decomp.) (再結晶容 媒:クロロホルムーnーへキサン); IR ν max cm $^{-1}$ 2216, 1650; NMR (400MHz, D MSO- d_6) δ ppm $1.83\sim2.32$ (6H, m), 3.42 (3H, s), 3.66 (1H, m), 7.28 (1H, d), 7.34 (1H, t), 7.45 (1H, d), 7.53 (1H, s), 7.53 (2H, d), 7.6

6 (1 H, s), 7. 91 (2 H, d); MS (FAB) m/z 441 (M⁺+1); 元素分析値 $C_{24}H_{20}N_6$ OS・1/4 H_2 O計算値 (%) C, 64. 77; H, 4. 64; N, 18. 88, 測定値 (%) C, 64. 98; H, 4. 75; N, 19. 04.

【0448】 [実施例147] N-(3-(2-(4 ーシクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-メチルーテトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) 4-(2-メチル-2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸の合成

メチル 4-(2-メチル-2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸を実施例56と同様に処理し、4-(2-メチル-2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸を 得た。

NMR $(400MHz, DMSO-d_6)$ δppm 4. 45(3H, s), 8. 11(2H, d), 8. 18(2H, d), 13. 2(1H, brs).

【0449】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-メチル-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

4- (2-メチル-2H-テトラゾール-5-イル) 安 息香酸と3- (2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -N-メチルーアニリンとを実施例10 4の工程2と同様に処理し、表題物を得た。

融点 200~202℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); IRνmax cm⁻¹ 2216, 16 56, 1606; NMR (400MHz, DMSOd₆) δppm 1.84~2.41 (6H, m), 3.71 (1H, m), 4.46 (3H,

s), 7.41(1H, d), 7.48(1H,

t), 7.53(1H, s), 7.88(1H, d), 8.15~8.16(3H, m), 8.21~8.24(2H, m), 10.56(1H, s); MS(FAB)m/z 441(M^+ +1); 元素分析值 $C_{24}H_{20}N_6$ OS·1/2 H_2 O計算值(%) C, 64.13; H, 4.71; N, 18.70, 測定值(%) C, 63.89; H,

4. 56; N, 18. 66.

【0450】 [実施例148] N-(3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) -2-メチルフェニル) -4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:4-(2-(メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸と3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) -2-メチルアニリンとを実施例104の工程2と同様に処理し、引き続き実施例1の工程5と同様に処理し、表題

物を得た。

融点 $223\sim225$ C (再結晶溶媒: クロロホルムーエタノールnーへキサン); IRvmax c m⁻¹ 22 08, 1640; NMR (400MHz, $DMSO-d_6$) δ p p m 1. $89\sim2$. 29 (6H, m), 2. 43 (3H, s), 3. $66\sim3$. 70 (1H, m), 7. 31 (1H, t), 7. 51 (1H, d), 7. 53 (1H, s), 7. 57 (1H, d), 8. 21 (4H, s), 7. 57 (1H, d), 8. 21 (4H, s), 10. 26 (1H, s); MS (FAB) m/z 441 (M^+ +1); 元素分析値 $C_{24}H_{20}N_6$ OS·1/ $4H_2$ O計算値 (%) C, 64. 77; H, 4. 64; N, 18. 88, 測定値 (%) C, 64. 60; H, 4. 58; N, 19. 08.

【0451】 [実施例149] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-メトキシ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -3-メトキシー 4-(1-(4-メトキシベンジル) -1H-テトラゾ ール-5-イル) ベンズアミド、及び N-(3-(2 -(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-メトキシー4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミ ドの合成

3-xトキシー4-(1-(x)トキシベンジル) -1 H - テトラゾール- 5 - イル) 安息香酸、及び 3-xトキシー4-(2-(x)トキシベンジル) -2 H- テトラゾール- 5 - イル) 安息香酸の混合物(1位:2位与1:1)と3-(2-(4-)シクロブチル- 2 - チアゾリル) エチニル) アニリンとを実施例103の工程1と同様に処理し、N-(3-(2-(4-)シクロブチル- 2 - 4 - + 2 - 4 - + 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 5 - 7 -

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 1.8 8~2.39 (6 H, m), 3.70 (1 H, m), 3.75, 3.77, 3.80 and 3.9 6 (6 H, each s), 5.39 and 5.79 (2 H, each s), 6.74 and 6.90 (2 H, each d), 6.95~6. 97 (2 H, m), 7.31 (1/2 H, d), 7.38~7.42 (4 H, m), 7.57~ 7.59 (1 H, m), 7.77 (1 H, m), 7.92(1/2H, d), 7.95(1/2H, d), 7.95(1/2H, d), 7.99(1/2H, d), 8.27(1/2H, s), 8.44(1/2H, s). 【0452】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3ーメトキシー4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

上記工程1で得た化合物を、実施例1の工程5と同様に 処理し、表題物を得た。

融点 $197\sim199$ °C; IR ν max c m⁻¹ 2208, 1654; NMR (400MH z, DMSO-d 6) δ p p m 1.85 \sim 2.35 (6H, m), 3.68 (1H, m), 4.10 (3H, s), 7.43 (1H, d), 7.51 (1H, t), 7.54 (1H, s), 7.77 (1H, d), 7.78 (1H, s), 8.13 (1H, s), 8.29 (1H, m), 10.58 (1H, s); MS (1FAB) m/z 457 $(M^+$ +1); 元素分析値 C_{24} H₂₀ N_6 O_2 S·H₂ O計算値 (%) C, 60.75; H, 4.67; N, 17.71, 測定値 (%) C, 60.74; H, 4.32; N, 17.16.

【0453】 [実施例150] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-メチル-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

 (工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -3-メチル-4 -(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾー ル-5-イル) ベンズアミドの合成

3-メチルー4-(2-(メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)安息香酸と3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)アニリンとを実施例103の工程1と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3-メチル-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドを淡黄色泡状物として得た。

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.9$ $1 \sim 2.39 (6 \text{H}, \text{m}), 2.71 (3 \text{H}, \text{s}), 3.69 (1 \text{H}, \text{m}), 3.81 (3 \text{H}, \text{s}), 5.78 (2 \text{H}, \text{s}), 6.92 (2 \text{H}, d), 6.96 (1 \text{H}, \text{s}), 7.38 \sim 7.43 (4 \text{H}, \text{m}), 7.73 \sim 7.77 (2$

H, m), 7.82(1H, s), 7.91 (2H, m), 8.16(1H, d).

【0454】N-(3-(2-(4-シクロプチル-2 -チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-メチル-4 -(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成 N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-メチル-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 128~130℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); IRνmax cm⁻¹ 2212, 1676, 1654; NMR (400MHz, DMSO-d6) δppm 1.87~2.35 (6H, m), 2.61 (3H, s), 3.68 (1H, m), 7.41 (1H, d), 7.49 (1H, t), 7.54 (1H, s), 7.87~7.98 (3H, m), 8.02 (1H, s), 8.14 (1H, s), 8.29 (1H, m), 10.54 (1H, s); MS (FAB) m/z 441 (M⁺+1); 元素分析値C₂₄H₂₀N₆ OS·1/2 H₂ O計算値 (%) C, 64.13; H, 4.71; N, 18.70.

【0455】 [実施例151] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -6-(1H-テトラゾール-5-イル) -2-チオフェンカルボキサミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) ー6ー (2- (4 ーメトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イ ル) -2-チオフェンカルボキサミドの合成 5- (2- (4-メトキシベンジル) - 2H-テトラゾ ール-5-イル)-2-チオフェンカルボン酸と3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニ ル)アニリンを実施例103の工程1と同様に処理し、 N- (3- (2- (4-シクロプチル-2-チアゾリ ル) エチニル) フェニル) -6-(2-(4-メトキシ ベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-チ オフェンカルボキサミドを淡黄色泡状物として得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.9 $1\sim2.39$ (6H, m), 3.70 (1H, m), 3.81 (3H, s), 5.73 (2H, s), 6.91 (2H, dt), 6.96 (1 H, s), 7.37 \sim 7.41(4H, m), 7. 64 (1H, d), 7. 68 (1H, m), 7. 78 (1H, d), 7. 84 (1H,

【0456】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-6-(1H-テトラゾール-5-イル)-2-チオフェンカルボキサミドの合成

s).

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) <math>-6-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-チ

オフェンカルボキサミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 224~228℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー メタノール); NMR (400MHz, DMSO-d 6) $\delta ppm 1.84\sim 2.34$ (6H, 3. 68 (1H, m), 7. 41 (1H, t), 7.49 (1H, t), 7.52 (1H, s), 7.82 ((1H, m), 7.87 (1 H, d), 8.08(1H, t), 8.13 (1H, d), 10.61(1H, s); MS (FAB) m/z 433 (M++1);元素分析值C 21H16N6 OS2 計算値(%) C, 58. 32; H, 3. 73; N, 19. 43, 測定値(%) C, 5 8. 26; H, 3. 90; N, 19. 48... 【0457】 [実施例152] N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ ル) -2-メチル-4-(1H-テトラソール-5-イ ル) ベンズアミド:

 (工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メチル-4 -(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾー ル-5-イル) ベンズアミドの合成

2-メチルー4-(2-(メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)安息香酸と3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)アニリンとを実施例103の工程1と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-メチルー4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドを得た。

融点 128~130℃; NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.91~2.40 (6H, m), 2.56 (3H, s), 3.68 (1H, m), 3.80 (3H, s), 5.74 (2H, s), 6.91 (2H, d), 6.95 (1H, s), 7.37~7.41 (3H, m), 7.56 (1H, d), 7.70 (2H, br s), 7.89 (1H, br s), 7.98 (1H, d), 8.03 (1H, s).

【0458】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メチル-4- (1H-テトラゾール-5-イル) ベン

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メチル-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点135~137°C; NMR (400MHz, DM $SO-d_6$) $\delta ppm1$. 84~2. 33 (6H,

ズアミドの合成

m), 2.50(3H, s), 3.67(1H, m), 7.41(1H, d), 7.48(1H, t), 7.54(1H, s), 7.73 (1H, d), 7.79(1H, d), 7.98(1H, d), 8.02(1H, s), 8.11(1H, s), 10.65(1H, s); MS(FAB) m/z 431(M^++1); 元素分析 値 $C_{24}H_{20}N_6$ OS·1/4 H_2 O計算値(%) C, 64.77; H, 4.64; N, 18.88, 測定値(%) C, 64.87; H, 4.87; N, 18.48.

【0459】 [実施例153] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メトキシ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 -チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メトキシー 4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾ ール-5-イル) ベンズアミドの合成

3-メトキシー4-(2-(メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)安息香酸と3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)アニリンとを実施例103の工程1と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-メトキシー4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドを淡黄色油状物として得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3)$ δppm 1. 9 $0\sim2$. 40 (6H, m), 3. 70 (1H, m), 3. 81 (3H, s), 4. 19 (3H, s), 5. 76 (2H, s), 6. 92 (2H, d), 6. 96 (1H, s), 7. 31 (1H, d), 7. $35\sim7$. 42 (4H, m), 7. 83 ~7 . 90 (4H, m), 8. 03 (1H, m), 9. 88 (1H, s).

【0460】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-メトキシ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N- (3- (2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メトキシー4- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 153~155°C (再結晶溶媒: クロロホルムーメタノールーnーヘキサン); IRνmax cm⁻¹ 2212, 1672; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.83~2.33 (6H, m), 3.67 (1H, m), 4.01 (3H, s), 7.40 (1H, dd), 7.47 (1

H, t), 7.54(1H, s), 7.75 (1H, dd), 7.82 \sim 7.84(3H, m), 8.08(1H, s), 10.44(1H, s); MS (FAB) m/z 457(M $^+$ +1); 元素分析值C₂₄H₂₀N₆O₂ S計算值(%)C, 63.14; H, 4.42; N, 18.41, 測定值(%)C, 63.54; H, 4.58; N, 18.57.

【0461】 [実施例154] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-メトキシフェニル) -4-(1H-テトラゾール-イル) ベンズアミド:

 (工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2 ーチアゾリル) エチニル) -2-メトキシフェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成

4- (2- (メトキシベンジル) -2H-テトラゾール -5-イル) 安息香酸と3- (2- (4-シクロブチル -2-チアゾリル) エチニル) -2-メトキシアニリン とを実施例104の工程2と同様に処理し、N- (3-(2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニ ル) -2-メトキシフェニル) -4- (2- (4-メト キシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベン ズアミドを淡黄色油状物として得た。

NMR $(400 \, \text{MHz}, \, \text{CDCl}_3) \, \delta \, \text{ppm} \, 1.9$ $4 \sim 2.40 \, (6 \, \text{H}, \, \text{m}) \, , \, 3.67 \sim 3.74 \, (1 \, \text{H}, \, \text{m}) \, , \, 3.80 \, (3 \, \text{H}, \, \text{s}) \, , \, 4.17 \, (3 \, \text{H}, \, \text{s}) \, , \, 5.76 \, (2 \, \text{H}, \, \text{s}) \, , \, 6.9 \, (2 \, \text{H}, \, \text{s}) \, , \, 6.99 \, (1 \, \text{H}, \, \text{s}) \, , \, 7.15 \, (1 \, \text{H}, \, \text{t}) \, , \, 7.32 \, (1 \, \text{H}, \, \text{dd}) \, , \, 7.40 \sim 7.42 \, (2 \, \text{H}, \, \text{m}) \, , \, 7.98 \sim 8.00 \, (2 \, \text{H}, \, \text{m}) \, , \, 8.27 \sim 8.29 \, (2 \, \text{H}, \, \text{m}) \, , \, 8.59 \, (1 \, \text{H}, \, \text{dd}) \, , \, 8.65 \, (1 \, \text{H}, \, \text{s}) \, .$

【0462】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メトキシフェニル)-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-メトキシフェニル) -2-メトキシー4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $186\sim187$ [°]C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルム-n-ヘキサン); $IR\nu$ max cm⁻¹ 2216, 1658; NMR (400MHz, DM $SO-d_6$) δ ppm 1. $86\sim2$. 31 (6H, m), 3. $63\sim3$. 72 (1H, m), 3. 97 (3H, s), 7. 24 (1H, t), 7. 51 (1H, dd), 7. 55 (1H, s),

7. 86 (1 H, d d), 8. 19 (2 H, d), 8. 22 (2 H, d), 10. 04 (1 H, s); MS (FAB) m/z 457 ($M^+ + 1$); 元素分析値 $C_{24}H_{20}N_6$ O_2 S·1/2 H_2 O 計算値 (%) C, 61. 92; H, 4. 55; N, 18. 05, 測定値 (%) C, 62. 18; H, 4. 53; N, 18. 27.

【0463】 [実施例155] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアソリル) エチニル) フェニル) -4-(1H-テトラゾール-5-イル) -2-トリフルオロメトキシベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアソリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-トリフルオロメトキシベンズアミドの合成4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-トリフルオロメトキシ安息香酸と3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-トリフルオロメトキシベンズアミドを得た。

融点 97~100℃ (decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルムーnーへキサン); $IRv \max c m^{-1}$ 3288, 2940, 2216, 1656, 160 8, 1586, 1548, 1514; NMR (400 MHz, CDCl₃) δ ppm 1. 89~2. 42 (6H, m), 3. $66 \sim 3$. 74 (1H, m), 3.81 (3H, s), 5.77 (2H, s), 6. $91\sim6$. 93 (2H, m), 6. 9 6 (1 H, s), 7. $37 \sim 7$. 43 (4 H, m), 7.69 \sim 7.72 (1H, m), 7.8 9 (1H, s), 8.14 (1H, s), 8. 22 (2H, s), 8.39 (1H, s); M S(EI) m/z 630(M⁺); 元素分析値C₃₂ H₂₅F₃N₆O₃Sの計算値(%) C, 60.95; H, 4.00; N, 13.33, 測定値(%) C, 60. 69; H, 4. 16; N, 13. 5

【0464】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(1H-テトラゾール-5-イル)-2-トリフルオロメトキシベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メトキシー4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-トリフルオロメトキシベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 199~202℃ (decomp.) (再結晶溶

媒:クロロホルム); $IRv \max cm^{-1} 3316$, 3 104, 2976, 2948, 2868, 2212, 1 658, 1624, 1608, 1584, 1548; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δ ppm 1. $83\sim2$. 31 (6H, m), 3. $63\sim3$. 72 (1H, m), 7.44 (1H, d), 7. 50 (1H, t), 7. 54 (1H, s), 7. 75 (1H, d), 8. 01 (1H, d), 8.06 (1H, s), 8.14 (1H, s), 8. 22 (1H, d), 10.87(1 H, s); MS (FAB) $m/z 511 (M^+ +$ 1); 元素分析值C₂₄H₁₇F₃N₆O₂S・0.25 H。Oの計算値(%) C, 55.97; H, 3.4 2; N, 16.32, 測定値(%)·C, 55.8 8; H, 3. 42; N, 16. 44. 【0465】[実施例156] N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ ル) -4- (1H-テトラゾール-5-イル) -2-ト リフルオロメチルベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-トリフルオロメチルベンズアミドの合成4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-トリフルオロメチル安息香酸と3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例103の工程1と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-トリフルオロメチルベンズアミドを淡黄色油状物として得た。

NMR $(400 \, \text{MHz}, \, \text{CDCl}_3) \, \delta \, \text{ppm} \, 1.8 \, 8 \sim 2.41 \, (6 \, \text{H, m}) \, , \, \, 3.63 \sim 3.72 \, (1 \, \text{H, m}) \, , \, \, 3.81 \, (3 \, \text{H, s}) \, , \, \, 5.76 \, (2 \, \text{H, s}) \, , \, \, 6.91 \sim 6.94 \, (2 \, \text{H, m}) \, , \, \, 6.95 \, (1 \, \text{H, s}) \, , \, \, 7.36 \sim 7.4 \, 2 \, (4 \, \text{H, m}) \, , \, \, 7.66 \sim 7.69 \, (1 \, \text{H, m}) \, , \, \, 7.73 \, (1 \, \text{H, s}) \, , \, \, 7.74 \, (1 \, \text{H, d}) \, , \, 7.84 \, (1 \, \text{H, s}) \, , \, \, 8.36 \, (1 \, \text{H, d}) \, , \, \, 8.49 \, (1 \, \text{H, s}) \, .$

【0466】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(1H-テトラゾール-5-イル)-2-トリフルオロメチルベンズアミドの合成

N- (3- (2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-トリフルオロメチルベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 201~205℃ (decomp.) (再結晶溶 3280, 2948, 2216, 1662, 160 8, 1580, 1538; NMR (400MHz, D $MSO-d_6$) δppm 1. $86\sim2$. 31 (6H, m), $3.63\sim3.71(1H, m)$, 7.44 (1H, d), 7.50 (1H, t), 7. 54 (1H, s), 7. 72 (1H, d), 8.03(1H, d), 8.05(1H, s), 8.46 (1H, d), 8.48 (1H, s), 10.93 (1H, s); MS (EI) m/z 494 (M⁺); 元素分析值C₂₄H₁₇F₃N 6 OSの計算値(%) C, 58.29; H, 3.4 6; N, 17.00, 測定值(%) C, 58.1 1; H, 3. 61; N, 16. 73. 【0467】 [実施例157] N-(3-(2-(4 ーシクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ ル) -2-フルオロ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド: (工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアソリル) エチニル) フェニル) ー4ー (2- (4 ーメトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イ ル) -2-フルオロベンズアミドの合成 2-フルオロー4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸と3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) アニ リンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エ チニル)フェニル) -2-フルオロ-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを淡黄色油状物として得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1. 9 $1\sim2.08$ (2H, m), 2.29 ~2.41 (4 H, m), 3.65 \sim 3.77(1H, m), 3.80 (3H, s), 5.75 (2H, s), 6. $90\sim6$. 92 (2H, m), 6. 95 (1 s), 7.36 \sim 7.41(4H, m), 7. $72 \sim 7$. 74 (1H, m), 7. 92 (1 H, s), 7.97 (1H, d), 8.08 (1H, dd), 8.28(1H, t), 8. 50 (1H, d). 【0468】 (工程2) N-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2 **-フルオロ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベ** ンズアミドの合成 N- (3- (2- (4-シクロプチル-2-チアソリ ル) エチニル) フェニル) -2-フルオロー4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理 し、表題物を得た。融点 179~181℃ (deco

mp.) (再結晶溶媒:クロロホルム-エタノール); $IRvmax cm^{-1} 3268, 2980, 2936,$ 2216, 1650, 1606, 1582, 1556; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δppm 1. $86\sim2$. 03 (2H, m), 2. $19\sim2$. $33(4H, m), 3.63\sim3.71(1H,$ m), 7.43 (1H, d), 7.49 (1H, t), 7.53(1H, s), 7.78(1 H, d), 7.94 (1H, t), 7.98 \sim 8. 03 (2H, m), 8. 08 (1H, s), 10. 78 (1H, s); MS (FAB) m/z4. 45 (M+ +1); 元素分析値C23H17FN6 OS ・0.75H₂ Oの計算値(%) C, 60.32; H, 4.07; N, 18.35, 測定値(%) C, 60. 41; H, 3. 84; N, 18. 10. 【0469】[実施例158] N-(3-(2-(4 - -シクロプチルー2 - チアゾリル) エチニル) フェニ ル) -3-フルオロ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド: (工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -3-フルオロー 4- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾ ールー5-イル) ベンズアミドの合成 3-フルオロ-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸と3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) アニ リンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エ チニル) フェニル) -3-フルオロ-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを淡黄色油状物として得た。 NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.9 $0\sim2.07$ (2H, m), 2.27 ~2.37 (4 H, m), 3.63 \sim 3.72(1H, m), 3. 79 (3H, s), 5. 78 (2H, s), 6. $89\sim6$. 91 (2H, m), 6. 95 (1 H, s), 7. $37 \sim 7$. 41 (4H, m), 7. $71 \sim 7$. 76 (3H, m), 7. 86 (1 H, s), 8. $18 \sim 8$. 22 (2H, 【0470】(工程2) N-(3-(2-(4-シク ロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -3 -フルオロ-4- (1H-テトラゾール-5-イル) ベ ンズアミドの合成 N- (3- (2- (4-シクロプチル-2-チアソリ ル) エチニル) フェニル) -3-フルオロ-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理 し、表題物を得た。 融点 224~226℃ (decomp.) (再結晶溶

2976, 2940, 2864, 2212, 1686, 1628, 1604, 1582, 1548; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δ ppm 1.86~2.03(2H, m), 2.21~2.33(4H, m), 3.63~3.71(1H, m), 7.43(1H, d), 7.50(1H, t), 7.54(1H, s), 7.87(1H, d), 8.03(1H, d), 8.07(1H, d), 8.14(1H, s), 8.25(1H, t), 10.63(1H, s); MS(FAB) m/z 445(M+1); 元素分析值C23H₁₇FN₆OSF·0.25H₂Oの計算值(%)C, 61.53; H, 3.93; N, 18.72, 測定值(%)C, 61.55; H, 3.94; N, 18.39.

【0471】 [実施例159] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(4-フルオロフェノキシ) メチルー4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド: (工程1) 2-(4-フルオロフェノキシ) メチルー4-(2-(2-(トリメチルシリル) エトキシメチル) -2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸の合成メチル 2-(4-フルオロフェノキシ) メチルー4-(2-(2-(トリメチルシリル) エトキシメチル) -2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸を実施例56と同様に処理し、2-(4-フルオロフェノキシ) メチルー4-(2-(2-(トリメチルシリル) エトキシメチル) -2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸を得た。

融点 $102\sim104$ °C; NMR (400MHz, CD Cl₃) δ ppm -0.01 (9H, s), 0.97 (2H, t), 3.76 (2H, t), 5.54 (2H, s), 5.96 (2H, s), 7.02 (4H, m), 8.25 (1H, d), 8.29 (1H, d), 8.65 (1H, s).

【0472】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(4-フルオロフェノキシ)メチル-4-(1 or2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成3-フルオロ-4-(2-(2-(トリメチルシリル)エトキシメチル-2H-テトラゾール-5-イル)安息香酸と3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理して得られた油状物を、引き続き、実施例76の工程2と同様に脱保護し、表題物を得た。

融点 98~99℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーメタ ノール); IRνmaxcm⁻¹ 2216, 1674; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.86~2.32 (6H, m), 3.67 (1

6. $99 \sim 7$. 02 (2H, m), $7. 08 \sim 7$. 12 (2H, m), 7.40 (1H, d). 7. 46 (1H, t), 7. 53 (1H, s), 7. 75 (1H, d), 7. 89 (1H, d), 8.06 (1H, s), 8.15 (1H, d), 8.33 (1H, s), 10.76 (1 H,, s); MS (FAB) $m/z 551 (M^+ +$ 1); 元素分析値C₃₀H₂₃FN₆O₂S・0.25H 2 Oの計算値(%) C, 64.91; H, 4.2 7; N, 15.14, 測定値(%) C, 64.8 7; H, 4. 30; N, 15. 19. 【0473】 [実施例160] N-(3-(2-(4 ーシクロプチルー2ーチアソリル) エチニル) フェニ ル) -3, 5-ジメトキシ-4- (1H-テトラゾール -5-イル) ベンズアミド: (工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2 ーチアソリル) エチニル) フェニル) -3, 5ージメト キシー4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テ トラゾールー5ーイル) ベンズアミドの合成 3, 5-ジメトキシー4-(2-(4-メトキシベンジ ル) -2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸と3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニ ル) アニリンを、実施例103の工程1と同様に処理 し、N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾ リル) エチニル) フェニル) -3, 5-ジメトキシー4 - (2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾー ルー5-イル) ベンズアミドを淡黄色油状物として得

H, quint), 5.38 (2H, s),

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.88~2.40 (6H, m), 3.46 (6H, s), 3.65~3.73 (1H, m), 3.73 (3H, s), 5.22 (2H, s), 6.71~6.73 (2H, m), 6.90~6.92 (2H, m), 6.96 (1H, s), 7.03 (2H, s), 7.33~7.37 (2H, m), 7.66~7.69 (1H, m), 8.17 (1H, s), 10.11 (1H, s). 【0474】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-3,5-ジメトキシー4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリ

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3, 5-ジメトキシ3-フルオロ-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 223~226℃ (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノール); IRνmax cm⁻¹ 2940, 2212, 1650, 1606, 157

8, 1530; NMR (400MHz, DMSO-d 6) $\delta ppm 1.85 \sim 2.33 (6H, m)$, 3. $63\sim3$. 71 (1H, m), 3. 85 (6 H, s), 7.37 (2H, s), 7.43 (1H, d), 7. 51 (1H, t), 7. 53 (1H. s), 7.89 (1H, d), 8.09 (1H, s), 10.50(1H, s); MS (FAB) m/z 487 (M+ +1); 元素分析 値C₂₅H₂₂N₆O₃S・0.25H₂Oの計算値(%) C, 61. 15; H, 4. 62; N, 17. 1 1, 測定値(%) C, 61.05; H, 4.6 5: N. 16. 77. 【0475】 [実施例161] N-(3-(2-(4 ーシクロプチルー2ーチアソリル) エチニル) フェニ (1)-5-イル) ベンズアミド: (工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2, 6-ジメトキ シー4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テト ラゾールー5ーイル) ベンズアミドの合成 2, 6-ジメトキシー4-(2-(4-メトキシベンジ ル) -2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸と3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニ ル) アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理 し、N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾ リル) エチニル) フェニル) -2, 6-ジメトキシー4 - (2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾー ルー5-イル) ベンズアミドを得た。 融点 174~178℃ (decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルムーn-ヘキサン); IRvmax cm $^{-1}$ 3348, 2940, 2212, 1684, 161 2, 1584, 1534, 1514; NMR (400M Hz, CDC13) $\delta ppm1$. 89~2. 39 (6)

融点 $174\sim178$ $^{\circ}$ (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーnーへキサン); IR $^{\circ}$ max cm $^{-1}$ 3348, 2940, 2212, 1684, 1612, 1584, 1534, 1514; NMR (400MHz, CDC13) δ ppm1. 89 $^{\circ}$ 2. 39 (6H, m), 3.65 $^{\circ}$ 3.73 (1H, m), 3.74 (3H, s), 3.94 (6H, s), 5.76 (2H, s), 6.91 $^{\circ}$ 6.93 (2H, m), 6.95 (1H, s), 7.35 $^{\circ}$ 7.41 (4H, m), 7.40 (2H, s), 7.52 (1H, s), 7.76 $^{\circ}$ 7.79 (1H, m), 7.84 (1H, s); MS (EI) m/z 606 (M $^{+}$); 元素分析値C33H30N604 S $^{\circ}$ 8.0.5H2 Oの計算値 (%) C, 64.37; H, 5.07; N, 13.65, 測定値 (%) C, 64.63; H, 4.91; N, 13.29.

【0476】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2,6-ジメトキシ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N- (3- (2- (4-シクロプチル-2-チアソリ

ル) エチニル) フェニル) -2, 6-ジメトキシー4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 169~173℃ (decomp.) (再結晶溶 2976, 2940, 2212, 1606, 158 4, 1554; NMR (400MHz, DMSO-d $_{6}$) δ ppm 1.84~2.31 (6H, m), 3. $65\sim3$. 74 (1H, m), 3. 90 (6 H, s), 7.37 (1H, d), 7.43 (2H, s), 7.44 (1H, t), 7.53 (1H, s), 7.73 (1H, d), 8.06 10.57 (1H, s); MS s), (FAB) m/z 487 (M⁺ +1); 元素分析 値C₂₅H₂₂N₆ O₃ Sの計算値(%) C, 61.7 1; H, 4. 56; N, 17. 27, 測定値 (%) C, 61. 43; H, 4. 55; N, 17. 02.

【0477】 [実施例162] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-クロロ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

 (工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-クロロ-4 -(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾー ル-5-イル) ベンズアミドの合成

2-クロロー4-(2-(4-メトキシベンジル)-2 H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸と3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニ リンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エ チニル) フェニル)-2-クロロー4-(2-(4-メ トキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル) ベ ンズアミドを黄色アモルファスとして得た。

NMR $(400 \, \text{MHz}, \, \text{CDCl}_3)$ $\delta \, \text{ppm}$ 1.8 $9 \sim 2.41$ $(6 \, \text{H}, \, \text{m})$, 3.65 \sim 3.73 $(1 \, \text{H}, \, \text{m})$, 3.81 $(3 \, \text{H}, \, \text{s})$, 5.76 $(2 \, \text{H}, \, \text{s})$, 6.91 \sim 6.93 $(2 \, \text{H}, \, \text{m})$, 6.96 $(1 \, \text{H}, \, \text{s})$, 7.39 \sim 7.42 $(4 \, \text{H}, \, \text{m})$, 7.72 \sim 7.74 $(1 \, \text{H}, \, \text{m})$, 7.88 $(1 \, \text{H}, \, \text{s})$, 7.89 $(1 \, \text{H}, \, \text{d})$, 8.04 $(1 \, \text{H}, \, \text{s})$, 8.13 $(1 \, \text{H}, \, \text{d})$, 8.24 $(1 \, \text{H}, \, \text{s})$. $(1 \, \text{H}, \, \text{d})$, 8.24 $(1 \, \text{H}, \, \text{s})$. $(1 \, \text{H}, \, \text{d})$, 8.75 $(1 \, \text{H}, \, \text{d})$, 8.76 $(1 \, \text{H}, \, \text{d})$, 8.77 $(1 \, \text{H}, \, \text{d})$, 8.77 $(1 \, \text{H}, \, \text{d})$, 8.77 $(1 \, \text{H}, \, \text{d})$, 8.78 $(1 \, \text{H}, \, \text{d})$, 8.79 $(1 \, \text{H}, \, \text{d})$, 8.70 $(1 \, \text{H}, \, \text{d})$, 9.70 $(1 \, \text{H}, \, \text{d})$

N- (3- (2- (4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-クロロ-4- (2-

ズアミドの合成

(4-メトキシベンジル) - 2 H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理 し、表題物を得た。

融点 $213\sim216$ C (decomp.) (再結晶溶媒: $x9/-\nu-n-\sim$ キサン); IR ν max cm $^{-1}$ 2944, 2212, 1644, 1612, 158 0, 1548, 1502; NMR (400MHz, D MSO $-d_6$) δ ppm 1.84 \sim 2.33 (6H, m), 3. $63\sim$ 3.72 (1H, m), 7.43 (1H, d), 7.50 (1H, t), 7.54 (1H, s), 7.76 (1H, d), 7.89 (1H, d), 8.07 (1H, s), 8.13 (1H, dd), 8.22 (1H, d), 10.87 (1H, s); MS (FAB) m/z 461 (1M+1); 元素分析値 C_{23} H+17 C1 N_6 OSの計算値 (%) C,59.93; H,3.72; N,18.23, 測定値 (%) C,59.78; H,3.79; N,17.88.

【0479】 [実施例163] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-フルオロフェニル) -4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2 -チアゾリル) エチニル) -2-フルオロフェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成

4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル) 安息香酸と3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)-2-フルオロアニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)-2-フルオロフェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)ベンズアミドを淡黄色油状物として得た。

IR ν max c m⁻¹ 2216; NMR (400MH z, CDCl₃) δ p p m 1.87~2.45 (6H, m), 3.71 (1H, m), 3.81 (3 H, s), 5.77 (2H, s), 6.92 (2H, d), 7.00 (1H, s), 7.2 (1H, t), 7.34 (1H, m), 7.42 (2H, d), 7.99 (2H, d), 8.13 (1H, br d), 8.25~8.33 (2H, m), 8.55 (1H, m); MS (EI) m/z 564 (M⁺); 元素分析値C₃₁H₂₅FN₆ O₂S·0.25H₂ Oの計算値(%) C, 65.41; H, 4.52; N, 14.77, 測定値(%) C, 64.96; H, 4.42; N, 15.01.

【0480】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-フルオロ

フェニル) -4- (1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-フルオロフェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $249\sim252$ ℃; IR ν max c m⁻¹ 330 0, 2220, 1650; NMR $(400MHz, DMSO-d_6)$ δ p p m 1. $77\sim2$. 35 (6H, m), 3. 68(1H, m), 7. 35 (1H, t), 7. 58 (1H, s), 7. 63(1H, m), 7. 76 (1H, m), 8. 22(4H, m), 10. 50 (1H, s); MS (FAB) m/z445 $(M^+ +1)$; 元素分析値 $C_{23}H_{17}FN_6$ OS· H_2 Oの計算値 (%) C, 59. 73; H, 4. 14; N, 18. 17, 測定値 (%) C, 59. 75; H, 3. 93; N, 18. 08.

【0481】 [実施例164] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -5-クロロ-2-メチル-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -5-クロロ-2-メチルー4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成 5-クロロ-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2 H-テトラゾール-5-イル) -2-メチル安息香酸と 3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) -2-フルオロアニリンを、実施例104の工程 2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -5-クロロ-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-メチルベンズアミドを得た。

融点 67~69℃ (decomp.) (再結晶溶媒:メタノールー水); NMR (400MHz, CDC13) δppm 1.90~2.00 (1H, m), 2.00~2.10 (1H, m), 2.20~2.40 (4H, m), 3.60~3.70 (1H, m), 3.81 (3H, s), 4.15 (3H, s), 5.81 (2H, s), 6.91 (2H, d), 7.30~7.40 (2H, m), 7.43 (1H, d), 7.71 (1H, s), 7.80 (1H, s), 7.85 (1H, d), 8.43 (1H, s).
【0482】 (工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -5

ークロロー2ーメチルー4ー(1H-テトラゾールー5

ーイル) ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-ジクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -5-クロロ-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-メチルベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 130~133℃ (decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルムーメタノールーn-ヘキサン); I R v max c m⁻¹ 1604, 1488, 1426, 13 80, 1286; NMR (400MHz, DMSO d_{6}) $\delta p p m 1. 80 \sim 1. 90 (1 H, m),$ 1. $90\sim2$. 10 (1H, m), 2. $20\sim2$. 4 $0 (4H, m), 3.60 \sim 3.80 (1H,$ m), 3. 95 (3H, s), 7. 42 (1H, d), 7.48 (1H, t), 7.53 (1H, s), 7.62(1H, s), 7.78(1 H, d), 7.88 (1H, s), 8.06 (1H, s), 10.52(1H, br s); MS (FAB) m/z 475 (M+1); 元素 分析値C₂₄H₁₉ClN₆OS・H₂Oの計算値(%) C, 54.60; H, 3.94; N, 15.28, 測定值(%) C, 54.87; H, 3.92; N, 15. 18.

【0483】 [実施例165] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メチルチオ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1): N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メチルチオ -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラ ゾール-5-イル) ベンズアミドの合成

4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)-2-メチルチオ安息香酸と3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)-2-メチルチオベンズアミドを黄色油状物として得た。

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.9$ $1 \sim 2.08 (2 \text{H, m}), 2.29 \sim 2.38 (4 \text{H, m}), 2,58 (3 \text{H, s}), 3.65 \sim$ 3.73 (1 H, m), 3.80 (3 H, s), 5.57 (2 H, s), 6.91 (2 H, $d), 6.95 (1 \text{H, s}), 7.37 \sim 7.4$ $1 (4 \text{H, m}), 7.77 \sim 7.84 (2 \text{H,}$ $m), 7.98 \sim 8.00 (2 \text{H, m}), 8.1$ 4 (1 H, d), 8.56 (1 H, s).

【0484】 (工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2

ーメチルチオー4- (1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-メチルチオベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 154~156℃ (decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルム-n-ヘキサン); IRvmax cm ⁻¹ 2212, 1650, 1606, 1582, 154 2; NMR $(400MHz, DMSO-d_6)\delta pp$ m 1.86 \sim 2.02(2H, m), 2.18 \sim 2. 31 (4H, m), 2. 56 (3H, s), 3. $62\sim3$. 71 (1H, m), 7. 41 (1 H, d), 7.48 (1H, t), 7.53 $(1 H, \cdot s)$, 7.77 (1 H, d), 7.78 (1H, d), 7. 98 (1H, d), 8. 0 2 (1H, s), 8.07 (1H, s), 1 0. 69 (1H, s); MS (EI) m/z 47 $3 (M^+ + 1)$; 元素分析値 $C_{24}H_{20}N_6 OS_2 \cdot 1$ /4H₂Oの計算値(%) C, 60.42; H, 4.33; N, 17.62, 測定値(%) C, 6 0. 61; H, 4. 39; N, 17. 58. 【0485】[実施例166] N-(3-(2-(4 ーシクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) ー6ーフ ルオロフェニル) - 4 - (1 H-テトラゾール-5-イ

 (工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2 -チアゾリル) エチニル) -6-フルオロフェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成

ル) ベンズアミド:

4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル) 安息香酸と3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル)-6-フルオロアニリンを、実施例<math>104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル) エチニル)-6-フルオロフェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドを得た。

融点 156~158°C (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); IRνmax cm⁻¹ 2216, 16 56; NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.91~2.39 (6H, m), 3.65~ 3.74 (1H, m), 3.80 (3H, s), 5.76 (2H, s), 6.90~6.92 (2 H, m), 6.95 (1H, s), 7.33~ 7.36 (1H, m), 7.39~7.42 (2 H, m), 7.98~8.00 (2H, m), 8.09 (1H, d), 8.27~8.29 (2 H, m), 8.77 (1H, dd); MS (F N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-フルオロフェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $218\sim220$ C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノールーnーへキサン); I R ν max c m $^{-1}$ 2216, 1650; NMR (400MHz, DMSO $^{-1}$ 0 $^{-1}$ 0 $^{-1}$ 0 $^{-1}$ 0 $^{-1}$ 0 $^{-1}$ 0 $^{-1}$ 0 $^{-1}$ 0 $^{-1}$ 1 $^{-1}$ 1 $^{-1}$ 1 $^{-1}$ 2 $^{-1}$ 1 $^{-1}$ 2 $^{-1}$ 2 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 1 $^{-1}$ 2 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 1 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 1 $^{-1}$ 2 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 1 $^{-1}$ 2 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 4 $^{-1}$ 6 $^{-1}$ 7 $^{-1}$ 5 $^{-1}$ 6 $^{-1}$ 7 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 8 $^{-1}$ 1 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 1 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 1 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 1 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 1 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 1 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 1 $^{-1}$ 2 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 4 $^{-1}$ 1 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 6 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 1 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 2 $^{-1}$ 1 $^{-1}$ 2 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 9 $^{-1}$ 3 $^{-1}$ 9 $^{-1$

【0487】 [実施例167] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(1H-テトラゾール-5-イル) -5-ピリジンカルボキサミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチルー2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -1-(2-(4 ーメトキシベンジル) -1H-テトラゾール-5-イル) -5-ピリジンカルボキサミド、及び N-(3-(2-(4-シクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -5-ピリジンカルボキサミドの合成

6-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)ニコチン酸と3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例103の工程1と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-1-(2-(4-メトキシベンジル)-1H-テトラゾールー5-イル)-5-ピリジンカルボキサミド、及びN-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)-5-ピリジンカルボキサミド(約1:1の混合物)を得

た。

融点 $208\sim230$ °C (再結晶溶媒:クロロホルムー $n- \wedge + \psi \nu$); $IR \nu \max cm^{-1} 1690$; N MR (400MHz, $DMSO-d_6$) $\delta ppm3.70$ and 3.75 (3H, each s), 5.97 and 6.13 (2H, each s), $6.88\sim6.98$ (2H, m), $7.31\sim7.43$ (2H, m), 8.26 and 8.38 (1H, each d), 8.45 and 8.52 (1H, each dd), 9.19 and 9.31 (1H, each dd), 9.19 and 9.31 (1H, each d), 13.69 (1H, br s); MS (EI) m/z 311 (1H) m/z m

【0488】 (工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-(1H-テトラゾール-5-イル) -5-ピリジンカルボキサミドの合成

上記、工程1の化合物を、実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 149~153℃(decomp.) (再結晶溶 2212, 1642; NMR (400MHz, DM $SO-d_6$) δppm 1. $84\sim2$. 35 (6H, m), $3.65\sim3.72$ (1H, m), 7.44 (1H, d), 7.52 (1H, t), 7.5 4 (1H, s), 7.87 (1H, d), 8. 14 (1H, s), 8.41 (1H, d), 8. 59 (1H, dd), 9. 30 (1H, d), 10.79 (1H, s); MS (FAB) m/z428 (M⁺+1); 元素分析値C₂₂H₁₇N₇ OS・1/4H₂ Oの計算値(%) C, 61.17; H, 4.08; N, 22.70, 測定値(%) C, 61. 04; H, 4. 14; N, 22. 52. 【0489】 [実施例168] N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ ル) -2, 6-ジメチル-4- (1H-テトラゾール-5ーイル) ベンズアミド:

ーチアゾリル)エチニル)フェニル)-2,6ージメチル-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2,6ージメチル安息香酸と3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)フェニル)-4-(2-(4-メトキ

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2

シベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル)-2, 6-ジメチルベンズアミドを淡黄色アモルファスとして 得た。

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.8$ $9 \sim 2.41 (6 \text{H}, \text{m}), 2.44 (6 \text{H}, \text{s}), 3.65 \sim 3.73 (1 \text{H}, \text{m}), 3.8} 1 (3 \text{H}, \text{s}), 5.74 (2 \text{H}, \text{s}), 6.90 \sim 6.93 (2 \text{H}, \text{m}), 6.96 (1 \text{H}, \text{s}), 7.36 \sim 7.41 (4 \text{H}, \text{m}), 7.5} 2 (1 \text{H}, \text{br s}), 7.67 \sim 7.70 (1 \text{H}, \text{m}), 7.83 (2 \text{H}, \text{s}), 7.91 (1 \text{H}, \text{s}).$

【0490】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2,6-ジメチル-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2, 6-ジメチルベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $218\sim222$ (decomp.) (再結晶溶媒: $x9/-\nu-n-n-n+\nu$); $IR\nu$ max cm^{-1} 2212, 1656; NMR (400MHz, $DMSO-d_6$) δ ppm 1. $84\sim2$. 35 (6H, m), 2. 40 (6H, s), 3. $63\sim3$. 71 (1H, m), 7. 42 (1H, d), 7. 48 (1H, t), 7. 53 (1H, s), 7. 76 (1H, d), 7. 83 (2H, s), 8. 10 (1H, s), 10. 74 (1H, s); MS (FAB) m/z 455 (M^+ + 1); 元素分析値 $C_{25}H_{22}N_6$ $OS \cdot 1/2H_2$ OO計算値 (%) C, 64. 78; H, 5. 00; N, 18. 13, 測定値 (%) C, 65. 02; H, 5. 03; N, 17. 83.

【0491】 [実施例169] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-プロモ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2

ーチアゾリル)エチニル)フェニル)-2-プロモー4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-プロモ安息香酸と3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-プロモベ

ンズアミドをアモルファスとして得た。
NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.8
9~2.41 (6H, m), 3.69 (1H, m), 3.74 (3H, s), 5.65 (2H, s), 6.74~7.81 (13H, m).
【0492】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2ープロモー4-(1Hーテトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-プロモベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 173~175℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); IR ν max c m⁻¹ 2212, 1662; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ p p m 1.88~2.28 (6H, m), 3.66 (1H, m), 7.38 (1H, d), 7.44 (1H, t), 7.52 (1H, s), 7.63 (1H, d), 7.74 (1H, d), 7.96 (2H, s), 8.11 (1H, s), 10.68 (1H, s); MS (FAB) m/z 507 [(M⁺+2) +1], 505 [(M⁺)+1]; 元素分析値C₂₃H₁₇BrN₆ OSの計算値(%) C, 54.66; H, 3.39; N, 16.63, 測定値(%) C, 54.30; H, 3.86; N, 16.42.

【0493】 [実施例170] メチル N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミノカルボニル-3-(1H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸:

(工程1) メチル N-(3-(2-(4-シクロブ チルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) アミノカ ルボニルー3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H ーテトラゾールー5ーイル) 安息香酸の合成 メチル 3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル) -5-ブロモ安息香酸1g、 3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチ ニル) アニリン695mg、1,3-ビス(ジフェニル フォスフィノ) プロパン52mg、及び酢酸[2]パラ ジウム28mgにトリエチルアミン5ml及びDMSO 15mlを加えた。反応系を一酸化炭素ガスで置換し、 120℃で10時間撹拌した。冷却後、反応液を濃縮し た。トルエン100mlを加え、これを1N塩酸、次い で飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶 媒を留去して得られる残渣をシリカゲルを用いるカラム クロマトグラフィー (溶出液:n-ヘキサン:酢酸エチ ル=3:1)で精製し、エーテルで結晶化させ、メチル $N - (3 - (2 - (4 - \nu) / 2 - \nu) / 2 - \nu)$ (2 - (4 - 3 + 5) - (2 + 4 - 3 + 5) アミノカルボニルー3 (2 - (4 - 3 + 5) - (2 + 4 - 3 + 5) アミノカルボニルー3 (2 + 4 + 5) - (2 + 4 + 5) アミノカルボニルー3 (2 + 4 + 5) アミノカル・3 (2 + 4 + 5)

融点 112~120℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー $n-n++\nu$); IR $\nu \max cm^{-1}$ 2212, 17 28; NMR (400MHz, CDC1₃) δ ppm 1. 87~2. 44 (6H, m), 3. 70 (1 H, m), 3.81 (3H, s), 4.00 (3H, s), 5.78(2H, s), 6.9 3 (2H, d), 6.97 (1H, s), 7. $38 \sim 7.45$ (4H, m), 7.73 (1H, m), 7.95 (1H, br·s), 8.01 (1H, br s), 8.61 (1H, t), 8.82 (1H, t), 8.97 (1H, MS (FAB) m/z 605 (M+1); 元素 分析値C₃₃H₂₈N₆ O₄ Sの計算値(%) C, 64. 58; H, 4. 76; N, 13. 70, 測定値 (%) C, 64. 55; H, 4. 66; N, 13. 36.

【0494】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-メチルチオ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

メチル N- (3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) アミノカルボニルー3 - <math>(2-(4-メトキシベンジル) - 2H-テトラゾール-5-イル) 安息香酸を実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 190℃ (decomp.) (再結晶溶媒:クロ ロホルムーエタノール); $IRv \max c m^{-1} 221$ 2, 1730; NMR (400MHz, DMSO-d 6) $\delta ppm 1.82\sim2.36 (6H, m)$, 3. 68 (1H, m), 3. 99 (3H, s), 7. 45 (1H, d), 7. 52 (1H, t), 7. 54 (1H, s), 7. 91 (1H, d), 8.15 (1H, s), 8.73 (1H, s), 8.83 (1H, s), 8.93 (1H, s), 10.85 (1H, s); MS (FA B) m/z 485 (M+ +1); 元素分析值C₂₅ H₂₀N₆O₃S・1/2H₂Oの計算値(%) C, 6 0.84; H, 4.29; N, 17.03, 測定 值(%) C, 60.59; H, 4.17; N, 1 6.85.

【0495】 [実施例171] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-エチル-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチルー2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-エチルー4 -(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾー ルー5ーイル)ベンズアミドの合成
4ー(2ー(4ーメトキシベンジル)-2Hーテトラゾールー5ーイル)-2ーエチル安息香酸と3ー(2ー(4ーシクロプチルー2ーチアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、Nー(3ー(2ー(4ーシクロプチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニル)-4ー(2ー(4ーメトキシベンジル)-2Hーテトラゾールー5ーイル)-2ーエチルベンズアミドをアモルファスとして得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1. 2 6 (3H, t), 1. 91~2. 39 (6H, m), 2. 93 (2H, q), 3. 69 (1H, m), 3. 81 (3H, s), 5. 76 (2 H, s), 6. 92 (2H, d), 6. 95 (1H, s), 7. 30~8. 10 (10H, m).

【0496】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-エチル-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N- (3- (2- (4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-エチルメチルチオベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 160~162℃ (再結晶溶媒:酢酸エチルー n ーへキサン); IR ν max c m ⁻¹ 2216, 1652; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ p p m 1.26 (3H, t), 1.87~2.33 (6H, m), 2.85 (2H, q), 3.67 (1H, m), 7.41 (1H, d), 7.48 (1H, t), 7.53 (1H, s), 7.63 (1H, d), 7.99 (1H, d), 8.05 (1H, s), 10.69 (1H, s); MS (FAB) m/z 455 (M + +1); 元素分析値C₂₅H₂₂N₆ OS·3/4H₂ Oの計算値(%) C, 64.15; H, 5.06; N, 17.96, 測定値(%) C, 64.43; H, 5.13; N, 17.65.

【0497】 [実施例172] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-ビニル-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

 (工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-ビニル-4 -(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾー ル-5-イル) ベンズアミドの合成

4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾ ール-5-イル)-2-ビニル安息香酸と3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)アニ リンを、実施例103の工程1と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-ピニルベンズアミドをアモルファスとして得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 1.9 1~2.39 (6H, m), 3.68 (1H, m), 3.81 (3H, s), 5.51 (1H, d), 5.76 (2H, s), 5.91 (1H, d), 6.69~8.35 (14H, m). 【0498】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-ビニルー4-(1Hーテトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-ビニルベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 168~172℃(decomp.) (再結晶溶媒:酢酸エチルーnーヘキサン); IR ν max c m⁻¹ 2212, 1646; NMR (400MH z, DM SO-d₆) δ p p m 1.83~2.34 (6H, m), 3.67 (1H, m), 5.51 (1H, d), 6.00 (1H, d), 7.04 (1H, dd), 7.42 (1H, d), 7.48 (1H, t), 7.53 (1H, s), 7.7 7~7.80 (2H, m), 8.07~8.10 (2H, m), 8.43 (1H, s), 10.76 (1H, s); MS (FAB) m/z 453 (M⁺ +1); 元素分析値C₂₅H₂₀N₆ OSの計算値(%) C,66.35; H,4.45; N,18.15, 測定値(%) C,66.19; H,4.44; N,17.79.

【0499】 [実施例173] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2,6-ジフルオロ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2

ーチアゾリル)エチニル)フェニル)-2,6ージフルオロー4ー(2ー(4ーメトキシベンジル)-2Hーテトラゾールー5ーイル)ベンズアミドの合成4ー(2ー(4ーメトキシベンジル)-2Hーテトラゾールー5ーイル)-2ー2,6ージフルオロ安息香酸と3ー(2ー(4ーシクロプチルー2ーチアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例103の工程1と同様に処理し、Nー(3ー(2ー(4ーシクロプチルー2ーチアゾリル)エチニル)フェニル)-4ー(2ー(4ーメトキシベンジル)-2Hーテトラゾールー5ーイル)-2,6ージフルオロベンズアミドを得た。

融点 150~153℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー $n - \uparrow + \psi$); IR $\nu \max c m^{-1}$ 2216, 16 58; NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1. $89 \sim 2$. 41 (6H, m), 3. $64 \sim$ 3. 73 (1H, m), 5. 75 (2H, s), 6. $91\sim6$. 93 (2H, m), 6. 95 (1 H, s), 7.36 \sim 7.41(4H, 7. $71 \sim 7$. 73 (1H, m), 7. 76 (2H, d), 7.87 (2H, s); MS (E I) m/z 512 (M⁺); 元素分析值C₃₁H₂₄F ₂ N₆ O₂Sの計算値(%) C, 63.91; H, 4. 15; N, 14. 42, 測定値(%) C, 6 4. 14; H, 4. 21; N, 14. 40. 【0500】(工程2) N-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) ー 2, 6-ジフルオロー4-(1H-テトラゾールー5-イル) ベンズアミドの合成 $N - (3 - (2 - (4 - \nu) - \nu) - 2 - F - V)$

N- (3- (2- (4-シクロプチル-2-チアソリル) エチニル) フェニル) -4- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2, 6-ジフルオロベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 227~233℃(decomp.) (再結晶溶 2212, 1664; NMR (400MHz, DM $SO-d_6$) δppm 1. $84\sim2$. 31 (6H, m), $3.63\sim3.71$ (1H, m), 7.46 (1H, d), 7.51 (1H, t), 7.5 4 (1H, s), 7.72 (1H, d), $90\sim7.92$ (2H, m), 8.05 (1H, s), 11.15 (1H, s); MS (FAB) m/z 463 (M⁺ +1); 元素分析値C₂₃H₁₆ F₂ N₆ OSの計算値(%) C, 59.73; H, 3.49; N, 18.17, 測定値(%) C, 5 9.83; H, 3.60; N, 18.19. 【0501】 [実施例174] N-(3-(2-(4 ーシクロプチルー2-チアゾリル) エチニル) フェニ ル) -2-フルオロー6-メチルチオー4-(1H-テ トラゾールー5ーイル)ベンズアミド: (工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロー6-メチルチオー4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-フルオロ-6-メチルチオ安息香酸と3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イ

ル) -2-フルオロー6-メチルチオペンズアミドを黄色アモルファスとして得た。

NMR $(400 \text{MHz}, \text{CDCl}_3) \delta \text{ppm} 1.9$ $1\sim 2.40 (6 \text{H, m}), 2.58 (3 \text{H, s}), 3.65\sim 3.73 (1 \text{H, m}), 5.7$ $6(2 \text{H, s}), 6.91\sim 6.93 (2 \text{H, m}), 6.96 (1 \text{H, s}), 7.38\sim 7.4$ $2(4 \text{H, m}), 7.67\sim 7.70 (1 \text{H, m}), 7.71\sim 7.74 (1 \text{H, m}), 7.7$ 6(1 H, s), 7.87 (1 H, s), 7.90 (1 H, s).

【0502】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-フルオロ-6-メチルチオ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-フルオロ-6-メチルチオベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 182~187℃ (decomp.) (再結晶溶媒:エタノールークロロホルム); IR ν max c m⁻¹ 2212, 1656; NMR (400MHz, DM SO-d₆) δ p p m 1.84~2.33 (6H, m), 2.62 (3H, s), 3.63~3.72 (1H, m), 7.44 (1H, d), 7.5 0 (1H, t), 7.54 (1H, s), 7.71 (1H, d), 7.75~7.78 (1H, m), 7.86 (1H, s), 8.05 (1H, s), 11.00 (1H, s); MS (FAB) m/z 491 (M⁺ +1); 元素分析値C₂₄H₁₉FN₆OS₂の計算値 (%) C,58.76; H,3.90; N,17.13, 測定値 (%) C,5 8.61; H,4.12; N,17.36.

【0503】 [実施例175] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-6-メトキシ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロー6-メトキシー4-(2-(4-メトキシベンジル) -2Hーテトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成4-(2-(4-メトキシベンジル) -2Hーテトラゾール-5-イル) -2-フルオロ-6-メトキシ安息香酸と3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2Hーテトラゾール-5-イル) -2-フルオロ-6-メトキシベンズアミドを淡黄色アモ

ルファスとして得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.8$ $9\sim2.41 (6H, m), 3.65\sim3.74 (1H, m), 3.81 (3H, s), 4.01 (3H, s), 5.76 (2H, s), 6.9 1\sim6.94 (2H, m), 6.95 (1H, s), 7.37\sim7.39 (2H, m), 7.39\sim7.42 (2H, m), 7.55\sim7.58 (1H, m), 7.58 (1H, s), 7.76\sim7.78 (1H, m), 7.84 (1H, s), 7.88 (1H, s).$

【0504】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-フルオロ-6-メトキシ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-フルオロ-6-メトキシベンズアミドを実施例<math>1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 210~213℃ (decomp.) (再結晶溶 媒:エタノールークロロホルム); $IRv max c m^{-1}$ 2216, 1680; NMR (400MHz, DM $SO-d_6$) $\delta ppm = 1.86\sim 2.33$ (6H, m), 3.63 \sim 3.71(1H, m), 3.9 7 (3H, s), 7.42 (1H, d), 7.4 8 (1H, t), 7.53 (1H, s), 7. 58 (1H, d), 7.65 (1H, s), 7. 72 (1H, d), 8. 05 (1H, s), 10. 87 (1H, s); MS (FAB) m/z475 (M⁺ +1); 元素分析値C₂₄H₁₉FN₆O 2 Sの計算値(%) C, 60.75; H, 4.0 4; N, 17.71, 測定値(%) C, 60.8 1; H, 4. 25; N, 17. 62. 【0505】[実施例176] N-(3-(2-(4 ーシクロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニ ル) -2-イソプロポキシ-4-(1H-テトラゾール -5-イル) ベンズアミド: (工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-イソプロポ キシー4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テ トラゾールー5ーイル) ベンズアミドの合成 4- (2- (4-メトキシベンジル) - 2H-テトラゾ ールー5ーイル) -2-イソプロポキシ安息香酸と3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニ ル) アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理 し、N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾ リル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキ シベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-

イソプロポキシベンズアミドを得た。

融点 124~125℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー $n - (n + \nu)$; IR ν max c m⁻¹ 2212, 16 70; NMR (400MHz, CDC1₃) δppm 1. 58 (6H, d), 1. 91~2. 40 (6 H, m), $3.66 \sim 3.74 (1 H, m)$, 3. 80 (3H, s), 4. $97\sim5$. 03 (1 H, m), 5.75 (2H, s), 6.89 \sim 6.93 (2H, m), 6.96 (1H, s), 7. $34 \sim 7$. 41 (4H, m), 7. $76 \sim$ 7. 79 (1H, m), 7. 84 (1H, 7. $86 \sim 7$. 88 (2H, m), 8. 39 (1)H, d), 10.26 (1H, s); MS (E I) m/z 604 (M⁺); 元素分析値C₃₄H₃₂N ₆O₃ Sの計算値(%)C, 67.52; H, 5.3 3; N, 13.90, 測定値(%) C, 67.4 7; H, 5. 44; N, 14. 02.

【0506】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-イソプロポキシー4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N- (3- (2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-イソプロポキシベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 207~210℃ (decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルム); IR ν max cm⁻¹ 2216, 1 672; NMR (400MHz, DMSO- d_6) δ $ppm 1.41 (6H, d), 1.86 \sim 2.3$ $3 (6 H, m), 3.63 \sim 3.71 (1 H,$ m), 4.80~4.86 (1H, m), 7.4 0 (1H, d), 7.48 (1H, t), 7. 53 (1 H, s), $7.72 \sim 7.76 (2 H,$ m), 7.79 (1H, s), 7.85 (1H, d), 8. 09 (1H, s), 10.38 (1 H, s); MS (EI) m/z 484 (M⁺); 元素分析値C₂₆H₂₄N₆ O₂ Sの計算値(%) C, 6 3. 27; H, 5. 10; N, 17. 03, 測定値 (%) C, 63.39; H, 4.87; N, 1 7. 25.

【0507】 [実施例177] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-ヒドロキシー4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-イソプロポキシ安息香酸97mg及び塩化アルミニウム53mgに1,2-ジクロロエタン20mlを加え、20時間加熱還流した。冷却後、反応液を1N塩酸30mlに加え、析出した結晶をろ取し、表題物を得た。

融点 160~163℃ (decomp.) (再結晶溶

媒:クロロホルムーエタノールー n 一へキサン); I R ν max c m⁻¹ 2212, 1644; NMR (40 0 MH z, DMSO- d_6) δ p p m 1.84~2.33 (6H, m), 3.63~3.71 (1H, m), 7.43 (1H, d), 7.49 (1H, t), 7.53 (1H, s), 7.63 (1H, dd), 7.71 (1H, d), 7.81 (1H, d), 8.08 (1H, d), 8.10 (1H, s), 10.58 (1H, s), 11.83 (1H, br s); MS (FAB) m/z 443 (M⁺ +1).

【0508】 [実施例178] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-ニトロ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

 (工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-ニトロー4 -(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾー ル-5-イル) ベンズアミドの合成

4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)-2-ニトロ安息香酸と3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)-2-ニトロベンズアミドを淡黄色アモルファスとして得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.8 8~2.40(6H, m), 3.68(1H, m), 3.81(3H, s), 5.78(2H, s), 6.93(2H, d), 6.96(1 H, s), 7.39~7.83(8H, m), 8.47(1H, d), 8.83(1H, s). 【0509】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2 ーニトロー4-(1Hーテトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-ニトロベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 >300℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); IR v max c m⁻¹ 2204, 1658, 1584, 1536, 1362, 1320; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ p p m 1.84~2.33 (6H, m), 3.67 (1H, m), 7.44 (1H, d), 7.50 (1H, t), 7.54 (1H, s), 7.69 (1H, d), 7.99 (1H, d), 8.03 (1H,

s), 8.52(1H, d), 8.78(1H, s), 11.00(1H, s); 元素分析値C₂₃H₁₇N₇O₃Sの計算値(%) C, 58.59; H, 3.63; N, 20.79, 測定値(%) C, 58.20; H, 3.86; N, 20.61.【0510】[実施例179] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-アミノ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミド:

 (工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-アミノー4 -(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾー ル-5-イル) ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-ニトロー4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドを参考例17と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-アミノベンズアミドを淡黄色アモルファスとして得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.9$ $0\sim2.41 (6H, m), 3.68 (1H, m), 3.80 (3H, s), 5.67 (2H, br), 5.75 (2H, s), 6.91 (2H, d), 6.96 (1H, s), 7.38~7.56 (8H, m)$

【0511】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアソリル)エチニル)フェニル)-2-アミノ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-アミノベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $164 \sim 168 ^{\circ}$ (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); NMR $(400 \text{MHz}, \text{DMSO-d}_{6})$ δ p p m $1.84 \sim 2.33$ (6 H, m), 3.67 (1 H, m), 7.22 (1 H, d), 7.39 (1 H, t), 7.51 (1 H, s), 7.53 (1 H, s), 7.80 (1 H, d), 7.85 (1 H, d), 8.11 (1 H, s), 10.32 (1 H, s); MS (FAB) m/z 442 $(\text{M}^+ + 1)$; 元素分析值 C_{23} C_{19} C_{19}

【0512】 [実施例180] N-(3-(2-(4

 (工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-イオド-4 -(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾー ル-5-イル) ベンズアミドの合成

4- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-イオド安息香酸と3- (2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N- (3- (2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-イオドベンズアミドをアモルファスとして得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) & ppm 1.8 4~2.39 (6H, m), 3.67 (1H, m), 3.81 (3H, s), 5.75 (2H, s), 6.92 (2H, d), 6.94 (1 H, s), 7.39~7.41 (4H, m), 7.61 (1H, d), 7.67 (1H, m), 7.72~7.74 (1H, m), 7.89 (1 H, s), 8.18 (1H, d), 8.67 (1 H, s).

【0513】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-イオド-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-イオドベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 152~154℃ (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.84~2.34 (6H, m), 3.67 (1H, m), 7.4 3 (1H, d), 7.50 (1H, t), 7.54 (1H, s), 7.76 (2H, d), 8.07 (1H, s), 8.18 (1H, d), 8.58 (1H, s), 10.77 (1H, s); 元素分析値C₂₃H₁₇IN₆OS·1/4H₂Oの計算値 (%) C, 49.61; H, 3.17; N, 15.09, 測定値 (%) C, 49.45; H, 3.42; N, 15.02.

【0514】 [実施例181] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアソリル) エチニル) フェニル) -2-メトキシ-6-メチル-4-(1H-テトラソール-5-イル) ベンズアミド

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチルー2

ーチアゾリル)エチニル)フェニル)-2ーメトキシー 6ーメチルー4ー(2ー(4ーメトキシベンジル)-2 Hーテトラゾールー5ーイル)ベンズアミドの合成 4ー(2ー(4ーメトキシベンジル)-2Hーテトラゾールー5ーイル)-2ーメトキシー6ーメチル安息香酸 と3ー(2ー(4ーシクロブチルー2ーチアゾリル)エ チニル)アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、Nー(3ー(2ー(4ーシクロブチルー2ーチア ゾリル)エチニル)フェニル)-4ー(2ー(4ーメト キシベンジル)-2Hーテトラゾールー5ーイル)-2 ーメトキシー6ーメチルベンズアミドを得た。

融点 75~77℃ (再結晶溶媒:水-エタノール);
NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1.
90~2.30 (6H, m), 2.34 (3H, s), 3.60~3.70 (1H, m), 3.7
6 (3H, s), 3.88 (3H, s), 5.
93 (2H, s), 6.97 (2H, d), 6.
98 (1H, s), 7.39~8.08 (8H, m).

【0515】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-メトキシ-6-メチル-4-(1H-テトラゾールー5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-メトキシ-6-メチルベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $181 \sim 184$ C (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); NMR (400MHz, DMSO-d $_6$) δ p p m $1.90 \sim 2.30$ (6 H, m), 2.34 (3 H, s), $3.60 \sim 3.70$ (1 H, m), 3.76 (3 H, s), 3.88 (3 H, s), 7.39 (1 H, t), 7.45 (1 H, d), $7.53 \sim 8.08$ (5 H, m), 10.52 (1 H, brs); MS (1 K) 10.52 (1 H, 10.52 (1

【0516】[実施例182] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-クロロ-6-フルオロ-4-(1 or 2 H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

 (工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -2-クロロー6 ーフルオロー4-(2-(4-メトキシベンジル) -2 Hーテトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成 4-(2-(4-メトキシベンジル) -2Hーテトラゾ ールー5ーイル) -2ークロロー6ーフルオロ安息香酸と3ー(2ー(4ーシクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、Nー(3ー(2ー(4ーシクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -4ー(2ー(4ーメトキシベンジル) -2Hーテトラゾールー5ーイル) -2ークロロー6ーフルオロベンズアミドをアモルファスとして得た。

NMR $(400MHz, CDCl_3) \delta ppm 1.9$ $0\sim 2.30 (6H, m), 3.60\sim 3.70 (1H, m), 3.76 (3H, s), 5.93$ (2H, s), 6.97 (2H, d), 6.9 $8 (1H, s), 7.39\sim 8.08 (9H, m).$

【0517】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-2-クロロー6-フルオロ-4-(1H-テトラゾールー5-イル)ベンズアミドの合成

N- (3- (2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-クロロ-6-フルオロベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 216~236℃ (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); NMR (400MHz, DMSO-de) δppm 1.90~2.30 (6H, m), 2.34 (3H, s), 3.60~3.70 (1H, m), 3.76 (3H, s), 7.39 (1H, t), 7.45 (1H, d), 7.54 ~8.08 (5H, m), 10.52 (1H, br s); MS (FAB) m/z 479 (M⁺ + 1).

【0518】 [実施例183] N-(3-(2-(4-tert-ブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-tert-プチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成

4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5-イル)-2-フルオロ安息香酸と3-(2-(4-tert-ブチルー2-チアゾリル)エチニル)アニリンを、実施例104の工程2と同様に処理し、N-(3-(2-(4-tert-ブチルー2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-フルオロベンズアミドを得た。

融点 212~213℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n-ヘキサン); IRνmax cm⁻¹ 2212, 16 58; NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1. 38 (9H, s), 3. 80 (3H, s), 5. 76 (2H, s), 6. 90~6. 9 3 (2H, m), 6. 97 (1H, s), 7. 36~7. 42 (4H, m), 7. 71~7. 74 (1H, m), 7. 93 (1H, s), 7. 9 7 (1H, dd), 8. 08 (1H, dd), 8. 28 (1H, t), 8. 50 (1H, d); MS (FAB) m/z 567 (M⁺ +1); 元素分析值C₃₁H₂₇FN₆ O₂ S·1/4H₂ Oの計算值 (%) C, 65. 19; H, 4. 85; N, 1 4. 71, 測定値 (%) C, 64. 96; H, 4. 80; N, 14. 57.

【0519】(工程2) N-(3-(2-(4-tert-プチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-フルオロ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-tert-プチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -4-(2-(4-)++シベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-フルオロベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 214~216℃ (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルム); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δppm 1.32 (9H, s), 7.47~7.50 (1H, m), 7.50 (1H, s), 7.77 (1H, d), 7.94 (1H, t), 7.98~8.03 (2H, m), 8.08 (1H, s), 10.77 (1H, s); MS (EI) m/z 446 (M⁺); 元素分析値C₂₃H₁₉FN₆ OS·1/4H₂ Oの計算値 (%) C, 61.25; H, 4.36; N, 18.63, 測定値 (%) C, 61.36; H, 4.42; N, 18.52.

【0520】 [実施例184] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-プロモ-4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

(工程1) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2

ーチアソリル)エチニル)フェニル)-5ープロモー3 ー (2-(4-メトキシベンジル)-2Hーテトラゾー ルー5ーイル)ベンズアミドの合成 3-(2-(4-メトキシベンジル)-2Hーテトラゾー ールー5ーイル)-5ープロモ安息香酸と3-(2-(4-シクロプチルー2ーチアゾリル)エチニル)アニ リンを、実施例103の工程1と同様に処理し、N-(3-(2-(4-シクロプチルー2ーチアゾリル)エ チニル)フェニル)-3-(2-(4-メトキシベンジ ル)-2Hーテトラゾールー5ーイル)-5ープロモベ ンズアミドを得た。

融点 167~174℃(再結晶溶媒:クロロホルムー $n-\Lambda + \psi$); IR $\nu \max c m^{-1}$ 2212; N MR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 1.87 ~ 2.44 (6H, m), 3.70 (1H, m), 3.80 (3H, s), 5.75 (2H, s), 6.92 (2H, d), 6.96 (1 H, s), 7.36 \sim 7.42(4H, m), 7. 73 (1H, m), 7. 90 (1H, s), 8.07 (1H, br s), 8.15 (1 H, t), 8.45 (1H, t), 8.49 (1H, br s); MS (FAB) m/z 625 (M⁺ +1); 元素分析値C₃₁H₂₅BrN₆O₂S ·H₂Oの計算値(%) C, 57.85; H, 3. 70; N, 13.06, 測定値(%) C, 58. 11; H, 4. 26; N, 13. 31. 【0521】(工程2) N-(3-(2-(4-シク ロブチルー2ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -5 ープロモー3ー(1Hーテトラゾールー5ーイル)ベン ズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -3-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -5-ブロモベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 217~222℃ (decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルム-n-ヘキサン); NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ ppm 1.85~2.3 8 (6H, m), 3.68 (1H, m), 7. 32 (1H, s), 7.37 (1H, 7. 44 (1H, t), 7. 88 (1H, br brt), d), 8.15 (1H, 8.36 (1H, brt), 8.44 (1H, t), 8.72 (1H, br t), 10.63 (1H, s); MS (FAB) m/z 505 $[(M^{+}+2)+1]$, 503 $[(M^{+})+1]$; 元素分析値C₂₃H₁₇BrN₆OS・3/4H₂Oの計算 值(%) C, 53.23; H, 3.59; N, 1 6. 20, 測定值(%) C, 53. 54; H, 3. 65; N, 15. 72.

【0522】 [実施例185] N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-ヒドロキシー6-メチル-4-(1H-テトラゾール-5-ベンズアミド:

N- (3- (2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -2-メトキシ-6-メチル-4- (1H-テトラゾール-5-ベンズアミドを実施例177と同様に処理し、表題物を得た。

融点 214~218℃ (decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルムーメタノール); NMR (400M Hz, DMSO-d_e) δppm 1.90~2.30 (6H, m), 2.34 (3H, s), 3.6 0~3.70 (1H, m), 7.35 (1H, t), 7.49 (1H, d), 7.53 (1H, s), 7.55 (1H, s), 7.62 (1 H, s), 7.82 (1H, d), 8.08 (1 H, s), 10.43 (1H, s), 10.52 (1H, s); MS (FAB) m/z 471 (M +1).

【0523】 [実施例186] N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N-ヒドロキシー4-(1H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミド:

 (工程1) N-(3-(2-(4-シクロブチル-2 ーチアゾリル) エチニル) フェニル) -N-ヒドロキシ -4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラ ゾール-5-イル) ベンズアミドの合成

N- (3-イオドフェニル) -N-ヒドロキシ-4- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール -5-イル) ベンズアミドと4-シクロプチル-2-エイニルチアゾールを実施例1の工程4と同様に処理し、N- (3- (2- (4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N-ヒドロキシー4- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを油状物として得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ ppm 1.9 $0\sim2$. 40 (6H, m), 3.60 \sim 3.70 (1H, m), 3.80 (3H, s), 5.75 (2H, s), 6.90 (2H, d), 7.3 $5\sim8$.30 (12H, m).

【0524】(工程2) N-(3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)フェニル)-N-ヒドロキシ-4-(1H-テトラゾール-5-イル)ベンズアミドの合成

N-(3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) フェニル) -N-ヒドロキシ-4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 167~170℃ (decomp.) (再結晶溶媒:酢酸エチルーメタノール); NMR (400MH z, DMSO-d₆) δppm 1.90~2.40 (6H, m), 3.60~3.70 (1H, m), 7.53 (1H s) 7.64 (1H

m), 7.53 (1H, s), 7.64 (1H, t), 7.87 (1H, d), 7.92 (1H, s), 8.07 (1H, d), 8.30 \sim 8.40 (5H, m); MS (FAB) m/z 443 (M⁺ +1).

【0525】 [実施例187] N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル) フェニル) -3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンズアミ

k :

(工程1) N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミドの合成

3- (2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) 安息香酸と4- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) アニリンを実施例1 03の工程1と同様に処理し、N- (4- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) フェニル) -3- (2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンズアミドを得た。

融点 179~180℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー n - (n + y); IR $v \max c m^{-1}$ 2216, 16 62; NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1. $94\sim2$. 40 (6H, m), 3. $66\sim$ 3. 73 (1H, m), 3. 80 (3H, s), 5. 73 (2H, s), 6. $89 \sim 6$. 92 (2 H, m), 6.99 (1H, s), 7.38 \sim 7.40 (2H, m), 7.52 (1H, t), 7. 75 (1H, d), 7. 80 (2H, d), 7.93 (1H, d), 8.03 (1H, s), 8.06 (1H, s), 8.15 (2H, d); MS (FAB) $m/z 5 4 7 (M^+ + 1)$; 元素分析値C₃₁H₂₆N₆ O₂ Sの計算値(%) C, 68.11; H, 4.79; N, 15.38, 測 定值(%) C, 67. 79; H, 4. 81; N, 15.24.

【0526】(工程2) N-(4-(1H-テトラゾ ール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロ ブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミドの合 成

N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾールー5ーイル)フェニル)ー3ー(2-(4-シクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) ベンズアミ ドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。 融点 245~246℃ (decomp.) (再結晶溶 2216, 1654; NMR (400MHz, DM $SO-d_6$) δppm 1. $96\sim2$. 32 (6H, m), 3.64~3.72(1H, m), 7.5 5 (1H, s), 7.67 (1H, t), 7.8 9 (1H, d), 8. $01 \sim 8$. 04 (3H, m), 8.07 (2H, d), 8.29 (1H, s), 10.65 (1H, s); MS (FA B) m/z 427 (M⁺ +1); 元素分析値C₂₃ H₁₈N₆ OS・1/4H₂ Oの計算値(%) C, 6 4.10; H, 4.33; N, 19.50, 測定 值(%) C, 63.89; H, 4.25; N, 1 9.37.

【0527】 [実施例188] N-(3-(1H-テトラゾール-5-イル) フェニル) -3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンズアミド・

(工程1) N-(3-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミドの合成

3- (2- (4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) 安息香酸と3- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) アニリンを実施例104の工程2と同様に処理し、N- (3- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) フェニル) -3- (2- (4-シクロプチル-2-チアソリル) エチニル) ベンズアミドを得た。

融点 185~186℃ (再結晶溶媒:クロロホルムー $n - (n + \nu)$; IR $\nu \max c m^{-1}$ 2216, 16 58; NMR (400MHz, CDCl₃) δppm 1. $92\sim2$. 40 (6H, m), 3. $69\sim$ 3. 73 (1H, m), 3. 79 (3H, s), 5. 72 (2 H, s), 6. $88 \sim 6$. 90 (2)H, m), 6.99 (1H, s), 7.37 \sim 7. 39 (2H, m), 7. $46 \sim 7$. 51 (2 H, m), $7.72 \sim 7.74$ (1H, m), 7. 92~7. 96 (3H, m), 8. 07 (1 H, s), 8.17 (1H, br s), 8. 29 (1H, s); MS (FAB) m/z 547 (M⁺ +1); 元素分析値C₃₁H₂₆N₆O₂Sの計 算值(%) C, 68.11; H, 4.79; N, 15.38, 測定値(%) C, 67.73; H, 4.86; N, 15.22.

【0528】(工程2) N-(3-(1H-テトラゾ ール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロ ブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミドの合 成

N - (3 - (2 - (4 -) +) +) - 2H - 7トラゾールー5ーイル) フェニル) -3-(2-(4-シクロプチルー2ーチアゾリル) エチニル) ベンズアミ ドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。 融点 162~164℃ (decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルムーエタノール); $IRv \max c m^{-1}$ 2216, 1662; NMR (400MHz, DM $SO-d_6$) δppm 1. 87~2. 34 (6H, m), 3. 64~3. 72 (1H, m), 7. 5 s), 7.61(1H, t), 7.6 5 (1H, t), 7.77(1H, d), 7. 7 (1H, 89 (1H, d), 7.98 (1H, d), 8. 10 (1H, d), 8. 32 (1H, s), 8. 62 (1H, s), 10. 63 (1H, s); MS (FAB) m/z 427 (M^+ +1);

元素分析値C₂₃H₁₈N₆ OS·1/4H₂ Oの計算値 (%) C, 64.10; H, 4.33; N, 1 9.50, 測定値(%) C, 64.38; H, 4.33; N, 19.45.

【0529】 [実施例189] N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル)-2-メトキシフェニル)-3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミド:

(工程1) N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-メトキシフェニル)-3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミドの合成

3- (2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) 安息香酸と2-メトキシー4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) アニリンを実施例103の工程1と同様に処理し、N-(4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-メトキシフェニル) -3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンズアミドをアモルファスとして得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 1. 9 0~2. 42 (6H, m), 3. 67~3. 75 (1 H, m), 3. 80 (3H, s), 4. 06 (3H, s), 5. 74 (2H, s), 6. 9 1 (2H, d), 6. 99 (1H, s), 7. 40 (2H, d), 7. 53 (1H, t), 7. 72 (1H, d), 7. 77 (1H, d), 7. 81 (1H, dd), 7. 96 (1H, d), 8. 08 (1H, s), 8. 63 (1H, s), 8. 65 (1H, d).

【0530】(工程2) N-(4-(1H-テトラゾ ール-5-イル)-2-メトキシフェニル)-3-(2 -(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベ ンズアミドの合成

N- (4- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) -2-メトキシフェニル) -3- (2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $220\sim221$ \mathbb{C} (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーnーへキサン); IR ν max cm $^{-1}$ 2216, 1682, 1656; NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ ppm 1.89 \sim 2.29 (6H, m), 3.66 \sim 3.72 (1H, m), 3.97 (3H, s), 7.55 (1H, s), 7.64 (1H, d), 7.67 (1H, t), 7.74 (1H, s), 7.88 (1H, d), 8.04 (1H, d), 8.05 \sim 8.08 (1H, m), 8.27 (1H, s), 9.86 (1H, s); MS (FAB) m/z

 $427 (M^+ + 1)$; 元素分析値 $C_{24}H_{20}N_6 O_2 S$ ・ $1/2H_2$ Oの計算値 (%) C, 61.92; H, 4.55; N, 18.05, 測定値 (%) C, 62.21; H, 4.42; N, 17.94. 【0531】 [実施例190] N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル) フェニル) -N-メチル-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンズアミド:

(工程1) N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-N-メチルー3-(2-(4-シクロブチルー2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミドの合成

3- (2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) 安息香酸とN-メチル-4- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) アニリンを実施例104の工程2と同様に処理し、N- (4- (2- (4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) フェニル) -N-メチル-3- (2- (4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンズアミドを得た。

NMR (400MHz, CDCl₃) δ p p m 1.8 7~2.41 (6H, m), 3.53 (3H, s), 3.68 (1H, m), 3.79 (3H, s), 5.70 (2H, s), 6.88 (2H, d), 6.94 (1H, s), 7.13 (1H, d), 7.15 (1H, t), 7.24 (1H, d), 7.36 (2H, d), 7.4 5 (1H, d), 7.62 (1H, s), 8.01 (1H, d).

【0532】(工程2) N-(4-(1H-テトラゾ ール-5-イル) フェニル) -N-メチル-3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) ベン ズアミドの合成

N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-N-メチル-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミドを実施例1の工程5と同様に処理し、表題物を得た。

融点 $114\sim117^{\circ}$ (decomp.); IR ν max cm $^{-1}$ 2216, 1650; NMR (400M Hz, DMSO $-d_6$) δ ppm 1.83 \sim 2.32 (6H, m), 3.44 (3H, s), 3.6 5 (1H, m), 7.33 (1H, t), 7.36 (1H, d), 7.46 (2H, d), 7.52 (1H, s), 7.58 (1H, d), 7.63 (1H, s), 7.93 (2H, d); MS (FAB) m/z 441 (M $^+$ +1); 元素分析值 $C_{24}H_{20}N_6$ OS·1/2 H_2 Oの計算值 (%) C, 64.12; H, 4.71; N, 18.70, 測定値 (%) C, 64.13; H, 4.9

2: N, 19.17.

【0533】 [実施例191] N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-メチルベンズアミド:前記と同様にして得られた、N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-6-メチルベンズアミドを同様に脱保護し、表題物を得た。

融点 $225\sim228$ C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーエタノール); NMR (400MHz, DMSO- d_6) δ ppm 1.80 \sim 2.40 (6H, m), 2.46 (3H, s), 3.60 \sim 3.80 (1H, m), 7.45 (1H, d), 7.52 (1H, s), 7.69 (1H, d), 7.82 (1H, s), 7.97 (2H, d), 8.04 (2H, d), 10.72 (1H, br s); MS (FAB) m/z441 (M⁺ +1); 元素分析値C₂₄H₂₀N₆ OS·1/2H₂ Oの計算値(%) C, 64.12; H, 4.71; N, 18.69, 測定値(%) C, 63.92; H, 4.65; N, 18.58.

【0534】 [実施例192] N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルベンズアミド:前記と同様にして得られた、N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)フェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)-2-メチルベンズアミドを同様に脱保護し、表題物を得た。

融点 184~186℃ (decomp.) (再結晶溶 1664; NMR (400MHz, DMSO-d 6) $\delta ppm 1.80 \sim 2.40 (6H, m)$, 2. 56 (3H, s), 3. $60\sim3$. 80 (1H, m), 7.44 (1H, t), 7.55 (1 H, s), 7.61(1H, d), 7.77 (1H, d), 7.97(2H, d), 8.0 4 (2H, d), 10.78 (1H, b r s); MS (FAB) m/z 441 (M^++1); 元素分析値C₂₄H₂₀N₆ OS・1/2H₂ Oの計算値 (%) C, 64. 12; H, 4. 71; N, 1 8.69, 測定値(%) C,64.12; H, 4. 62; N, 18. 52.

【0535】 [実施例193] N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル)-2-メチルフェニル)-3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル)エチニル)ベンズアミド:前記と同様にして得られた、N-(4-(2-(4-メトキシベンジル)-2H-テトラゾール-5-イル)-2-メチルフェニル)-3-(2

- (4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニル) ベンズアミドを同様に脱保護し、表題物を得た。

融点 $135\sim138$ ^C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノールーnーへキサン); NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ ppm1.80~2.40(6H, m), 2.38(3H, s), 3.60~3.80(1H, m), 7.55(1H, s), 7.60~7.70(2H, m), 7.80~7.90(2H, m), 8.00(1H, s), 8.09(1H, d), 8.30(1H, s), 10.20(1H, s); MS(FAB) m/z 441(M⁺+1).

【0536】 [実施例194] Nー(4ー(1Hーテトラゾールー5ーイル)フェニル)ー3ー(2ー(4ーシクロプチルー2ーチアゾリル)エチニル)ー2ーフルオロベンズアミド:前記と同様にして得られた、Nー(4ー(2ー(4ーメトキシベンジル)ー2Hーテトラゾールー5ーイル)フェニル)ー3ー(2ー(4ーシクロプチルー2ーチアゾリル)エチニル)ー2ーフルオロベンズアミドを同様に脱保護し、表題物を得た。

融点 $222\sim226$ C (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); IR ν max c m⁻¹ 1682; NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ p p m 1.90~2.40 (6 H, m), 3.60~3.80 (1 H, m), 7.51 (1 H, t), 7.54 (1 H, s), 7.90 (1 H, d), 7.91 (1 H, d), 7.9 (1 H, d), 8.05 (1 H, d), 10.86 (1 H, s); MS (1 H, d), 4.45 (1 M+1).

【0537】 [実施例195] N-(4-(1H-テトラゾール-5-イル) フェニル) -3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-フルオロベンズアミド: 前記と同様にして得られた、N-(4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラゾール-5-イル) フェニル) -3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エチニル) -6-フルオロベンズアミドを同様に脱保護し、表題物を得た。

融点 226~229℃ (decomp.) (再結晶溶媒:クロロホルムーメタノール); NMR (400M Hz, DMSO-d6) δppm 1.90~2.40 (6H, m), 3.60~3.80 (1H,

m), 7.45(1H, d), 7.48(1H, s), 7.60(1H, s), 7.83(1H, dd), 7.95(2H, d), 8.05(2H, d), 10.88(1H, s); MS(FAB) m/z 445(M⁺+1);元素分析値C₂₃H₁₇FN₆OS·1/2H₂Oの計算値(%) C, 60.92; H, 4.00; N, 18.53, 測定値(%) C, 60.73; H, 4.12; N,

18. 29.

【0538】 [実施例196] N-(4-(1H-テ トラゾールー5ーイル) -2-フルオロフェニル) -3 - (2- (4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニ ル) ベンズアミド:前記と同様にして得られた、N-(4-(2-(4-メトキシベンジル) -2H-テトラ ソールー5ーイル) -2-フルオロフェニル) -3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エチニ ル) ベンズアミドを同様に脱保護し、表題物を得た。 融点 236~239℃ (decomp.) (再結晶溶 媒:クロロホルムーメタノール); NMR (400M Hz, $DMSO-d_6$) δppm 1. $90\sim2$. 40 (6 H, m), 3. $60 \sim 3$. 80 (1 H,m), 7.55(1H, s), 7.68(1H, t), 7.90 \sim 8.00 (5H, m), 09 (1H, d), 8.31 (1H, s), 0. 54 (1H, s); MS (FAB) m/z 4 $45 (M^+ + 1)$.

【0539】 [実施例197] 製剤例:錠剤の製造よく粉砕した実施例1の化合物1000mg. 乳糖5900mg、結晶セルロース(MCC)2000mg、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース(LHPC)1000mg、ステアリン酸マグネシウム100mgをよく混合し、直接打錠法にて1錠100mg中前記化合物10mgを含有する素錠を製造した。この素錠に糖衣またはフィルムコートを施して糖衣錠及びフィルムコート錠を製造した。

【0540】[実施例198] 製剤例:錠剤の製造よく粉砕した実施例157の化合物1000mg、乳糖5900mg、結晶セルロース(MCC)2000mg、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース(LHPC)1000mg、ステアリン酸マグネシウム100mgをよく混合し、直接打錠法にて1錠100mg中前記化合物10mgを含有する素錠を製造した。この素錠に糖衣またはフィルムコートを施して糖衣錠及びフィルムコート錠を製造した。

【0541】 [実施例199] 製剤例:カプセル剤の 製造

よく粉砕した実施例1の化合物1000mg、トウモロコシデンプン (コーンスターチ) 3000mg、乳糖6900mg、結晶セルロース (MCC) 1000mg、ステアリン酸マグネシウム100mgをよく混和して1カプセル120mg中前配化合物10mgを含有するカプセル錠を製造した。

【0542】 [実施例200] 製剤例:カプセル剤の 製造

よく粉砕した実施例157の化合物1000mg、トウモロコシデンプン (コーンスターチ) 3000mg、乳糖6900mg、結晶セルロース (MCC) 1000mg、ステアリン酸マグネシウム100mgをよく混和し

て1カプセル120mg中前記化合物10mgを含有するカプセル錠を製造した。

【0543】 [実施例201] 製剤例:吸入剤の製造 ソルビタンモノオレート50mgを5mlエアゾール用 アルミ容器に摂取し、フレオン-111mlを加えて懸濁した。よく粉砕、乾燥した実施例1の化合物50mgを加え超音波を照射して分散させた。100 μ 1 の定量バルブを装着し、加圧状態でバルブを介しフレオン-124 mlを充填する。1噴射100 μ 1 あたり前配化合物1 mgを含有する定量噴霧の吸入剤(MDI)を製造した。

【0545】式(1)で表される本発明の化合物及びそれらの塩は、例えば気管支狭窄の阻害活性を有しており、喘息やアレルギー反応などの軽減や予防を達成可能な気管支肺薬剤として有用である。本発明の式(1)の化合物の有用な医薬活性の例を以下の試験例により具体的に示すが、本発明の化合物の作用はこれらの試験例で明らかにされたものに限定されることはなく、下記の試験例によって本発明の範囲が限定されることはない。

【0546】 [試験例1] モルモット摘出回腸を用いたLTD $_4$ 拮抗試験

ハートレー系雄性モルモットの回腸を用い、マグヌス法により測定した。即ち、モルモットを放血致死させた後、回腸を摘出した。回腸を1~1.5 cmの長さに切り、さらに縦走筋方向に切開して回腸標本を作製した。この標本を10m1のタイロード液(35℃,95%酸素-5%炭酸ガス通気)を満たしたマグヌス管に懸垂した後、1gを負荷した。ヒスタミン(10⁻⁴M)で3~4回収縮させた後、LTD4の収縮反応が安定してからLTD4の収縮に対する被験物質の作用を検討した。回腸の収縮はアイソトニックトランスデューサー(日本光電:TD-112S)を介してレコーダー(理科電気:R-64VS)に記録した。被験物質はジメチルスルフ

オキシド (DMSO) に溶解し、LTD4 (最終濃度1 0^{-8} M) 添加5分前にマグヌス管内に加えた。成績は、同一標本で溶媒処理したLTD4 による回腸の収縮を対照とし、被験物質を処理したLTD4による回腸収縮を比較して抑制率を求め、抑制率の一時回帰直線から最小二乗法により50%抑制用量 (IC_{50}) を算出した。

【0547】 [試験例2] ヒスタミン遊離抑制試験 Sprague-Dawley系雄性ラット (250~ 350g)を断頭放血死させた後、5U/m1のヘパリ ンを含有するmodified—Tyrode液 [Na Cl 124mM, KCl4mM, CaCl₂ 1.0 mM, MgCl₂ 0.5 mM, NaH₂ PO₄ · H₂ OO. 64mM, NaHCO3 10mM, Guluc ose 5.6 mM, Gelatin 0.05% (w/ v)] 20m1をラット腹腔内に注入した。腹部を60 秒間軽くマッサージした後、切開して腹腔内液を回収し た。腹腔液を遠心分離 (250×g, 4℃, 5分間) し て得た細胞を、ヘパリンを含まないmodified-Tyrode液で、2回洗浄した。この腹腔浸出細胞液 (肥満細胞として約 10^7 cells/ml) に 80μ 1の抗DNP-IgE抗体を加え37℃で30分間イン キュベートすることにより肥満細胞を感作した。その 後、腹腔浸出細胞液に含まれる肥満細胞数が8×10⁵ cells/mlになるようにヘパリンを含まないmo difiedーTyrode液を加えて調整した。この 細胞浮遊液 250 μ l に抗原 (最終濃度 30 n g/m 1)を含む被験溶液を50μ1添加して37℃で5分間 インキュベーションした後、反応停止液 [NaCl 1 20 mM, KCl 5 mM, EDTA 1 mM, Tri s-HC1 (pH=7.4) 25 mM, BSA 200 μ g/m1] 200 μ 1を加え反応を停止させた。その 後、遠心分離 (250×g, 4℃, 5分間) して得た上 清250μl中のヒスタミン濃度をShoreらの方法 を用いて測定した。被験物質は抗原の添加と同時に加 え、その抑制効果は各濃度の抑制率の一次回帰直線から 最小二乗法により算出した50%抑制用量(IC₅₀)で 示した。

【0548】モルモット摘出回腸を用いたLTD $_4$ 拮抗 試験及びヒスタミン遊離抑制試験における実施例化合物 の IC_{50} 値は以下の通りであった。

[0549]

【表1】

| 被験物質 (実施例番号) | 回腸収縮抑制率 (IC ₅₀) | ヒスタミン遊離 抑制作用(IC _{so}) |
|--------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 3. 6×10 ⁻⁸ | 6. 5×10 ⁻⁸ |
| 4 | 1. 9×10^{-8} | 1. 2×10^{-7} |
| 5 | 2. 8×10^{-8} | 1. 5×10^{-7} |
| 6 | $3. 0 \times 10^{-8}$ | 1. 2×10^{-7} |

```
9. 9 \times 10^{-8}
                          1. 2 \times 10^{-8}
    7
                                                    7. 5 \times 10^{-7}
  17
                          1. 2 \times 10^{-8}
                                                    2.2 \times 10^{-7}
                          1. 3 \times 10^{-7}
  20
                          2.0 \times 10^{-7}
                                                    1. 5 \times 10^{-7}
  23
                          1. 7 \times 10^{-7}
                                                    1. 2 \times 10^{-7}
  25
                          2. 8 \times 10^{-7}
                                                    1. 1×10<sup>-8</sup>
  26
                          1. 1 \times 10^{-7}
                                                    1. 0 \times 10^{-7}
  3 5
                          1. 3 \times 10^{-8}
                                                    1. 7 \times 10^{-7}
  39
  40
                          6. 6 \times 10^{-8}
                                                    2. 8 \times 10^{-7}
                          7. 9 \times 10^{-8}
                                                    3. 1 \times 10^{-7}
  4 1
                          2. 7 \times 10^{-8}
                                                    2.0 \times 10^{-6}
  4 2
                          4. 1 \times 10^{-8}
                                                    1. 8 \times 10^{-6}
  45
                          7. 3 \times 10^{-9}
                                                    3. 5 \times 10^{-8}
  68
                          7. 8 \times 10^{-9}
                                                    1. 1 \times 10^{-7}
  69
                                                    7. 1 \times 10^{-7}
                          1. 5 \times 10^{-8}
  70
                                                    2.4 \times 10^{-7}
  76
                          1. 1×10<sup>-8</sup>
                          2. 6 \times 10^{-9}
                                                    5. 5 \times 10^{-7}
  78
101
                          2. 2 \times 10^{-8}
                                                    5. 4 \times 10^{-7}
                          1. 5 \times 10^{-8}
                                                    1. 2 \times 10^{-9}
103
                          4. 9 \times 10^{-8}
104
                                                    1. 5 \times 10^{-8}
                          3.2 \times 10^{-8}
                                                    1. 3 \times 10^{-7}
110
                                                    2.7 \times 10^{-8}
125
                          2. 0 \times 10^{-9}
                          1. 9 \times 10^{-9}
                                                    2. 6 \times 10^{-7}
126
                          1. 8×10<sup>-9</sup>
                                                    3. 8 \times 10^{-7}
127
129
                          7. 0 \times 10^{-9}
                                                    7. 0 \times 10^{-7}
                          8. 5 \times 10^{-8}
                                                    1. 7 \times 10^{-7}
131
                          9. 4 \times 10^{-10}
                                                    5. 9 \times 10^{-9}
141
                          1. 9 \times 10^{-9}
                                                    5. 4 \times 10^{-7}
142
                          2. 5 \times 10^{-10}
                                                    1. 5 \times 10^{-8}
152
                          5. 4 \times 10^{-10}
153
                                                    7. 4 \times 10^{-9}
                          1. 0 \times 10^{-8}
                                                    7. 4 \times 1.0^{-9}
155
                          5. 7 \times 10^{-10}
                                                    9. 3 \times 10^{-9}
157
                          2.3 \times 10^{-10}
                                                    7. 0 \times 10^{-9}
161
                          7. 9 \times 10^{-10}
162
                                                    1. 8×10<sup>-9</sup>
                        1. 1 \times 10^{-9}
                                                    8. 2 \times 10^{-8}
163
                          2. 6 \times 10^{-9}
                                                    1. 0 \times 10^{-7}
164
                          1. 0 \times 10^{-9}
                                                    9. 4 \times 10^{-9}
165
                          4. 5 \times 10^{-9}
                                                    1. 0 \times 10^{-7}
167
                          8. 2 \times 10^{-10}
                                                    3. 1 \times 10^{-8}
168
                          1. 6 \times 10^{-9}
                                                    4. 7 \times 10^{-10}
172
                          6. 4 \times 10^{-10}
                                                    4. 1 \times 10^{-8}
173
                          6. 6 \times 10^{-10}
                                                    4. 0 \times 10^{-8}
174
                          2. 0 \times 10^{-10}
                                                    1.8×10<sup>-8</sup>
175
                                                    8. 1 \times 10^{-8}
                          2. 6 \times 10^{-9}
179
                          2. 3 \times 10^{-10}
                                                    2. 5 \times 10^{-8}
180
181
                          1. 1 \times 10^{-10}
                                                    5. 9 \times 10^{-8}
                          2. 3 \times 10^{-9}
                                                    2.6 \times 10^{-8}
182
                          1. 8 \times 10^{-9}
                                                    5. 5 \times 10^{-9}
183
                          1. 2 \times 10^{-8}
                                                    1. 7×10<sup>-8</sup>
189
                          4. 2 \times 10^{-8}
                                                    7. 8 \times 10^{-8}
196
```

【0550】 [試験例3] LTD₄ 誘発気道収縮抑制 試験

ハートレー系雄性モルモットを用い、ウレタン麻酔下(1.5g/5m1/kg, i.p.)に気管カニューレー及び静脈カニューレーを挿着した。人工呼吸器を気管カニューレーに接続し、換気量約10m1/kg、換気回数60回/分で人工呼吸を行った。LTD $_4$ 投与5分前にプロプラノロール(1mg/kg)、3分前にスクシニルコリン(1mg/kg,自発呼吸を停止させるため)さらに2分前にインドメタシン(2mg/kg)を静脈内投与した。換気量を気道内圧が10cmH $_2$ O/1/sec.となるように調節した後、LTD $_4$ (4 μ g/kg)を静脈内投与して気道収縮を惹起させた。

被験物質は、0.5%カルボキシメチルセルロース(CMC)に懸濁して惹起前の至適投与時間に経口投与した。気道収縮は気管を完全閉塞して得られた最大反応に対する百分率で表し、抑制率は溶媒投与群のLTD4による最大収縮率をコントロールとして被験物質投与群の最大収縮率から求めた。成績は抑制率の一時回帰直線から最小二乗法により求めた50%抑制用量(ID_{50})で示した。実施例化合物のLTD4 誘発気道収縮抑制試験における ID_{50} 値は以下の通りであった。また、気道収縮抑制の持続時間は被験物質を経口投与(10mg/kg)して8時間または12時間後の抑制率を測定した。【0551】

【表 2】

| 被験物質 | I D ₅₀ (m g/k g) | 活性持続[| 10mg/kg(p.o.) |
|---------|-----------------------------|-------|---------------|
| (実施例番号) | • | 8 h | 1 2 h |
| 1 | 1. 1 | 75% | |
| 4 | 1. 3 | 60% | |
| 5 | 2.6 | | |
| 6 . | 2.4 | 76% | |
| 1 7 | 4. 1 | | |
| 2 0 | 3. 1 | | |
| 3 9 | 1. 3 | 67% | |
| 4 2 | 2. 7 | | |
| 4 5 | 1. 9 | | |
| 7 8 | 5. 1 | | |
| 1 2 5 | 3.8 | 75% | |
| 127 | 1. 9 | | |
| 150 | 3. 0 | • | |
| 152 | 0. 7 | | |
| 155 | 2. 0 | | • |
| 157 | 0.4 | | 8 1 % |

【0552】[試験例4] PCA (Passive cutaneous anaphylaxis) 反応抑制試験

Sprague—Dawley系雄性ラット(170~220g)の背部を剪毛した後、生理的食塩水で15倍に希釈した、抗egg albuminラット血清(ラット48時間PCA titer:514倍)を背部2カ所に皮内注射(50μl/site)して感作した。感作後48時間に5/mgのegg albuminを含む0.5%エバンスブルー生理的食塩水1mlを静脈内投与してPCA反応を惹起した。30分後断頭放血死させ、背部の青染部を切り取り、Katayamaらの方法2)で皮膚青染部の色素を抽出測定した。被験物質は、0.5%カルボキシメチルセルロースに懸濁して惹起直前の至適投与時間に経口投与した。成績は溶媒投与

群の色素漏出量から抑制率を求め、抑制率の回帰直線から最小二乗法により求められた50%抑制濃度(ID_{50})で示した。PCA試験の ID_{50} 値は以下の通りであった。

【0553】 【表3】

| 被験物質 (実施例番号) | 抑制率 (I D ₅₀) |
|--------------|-----------------------------|
| 1 | 1. 5 |
| 4 | 2. 3 |
| 5 | 3.6 |
| 6 | 2. 4 |
| 7 | 0.5 |

| 1 9 | 0.6 |
|-------|------|
| 3 9 | 2. 3 |
| 1 2 5 | 3. 1 |
| 153 | 4. 1 |
| 157 | 3.8 |

【0554】 [試験例5] 光安定性試験

被験物質の濃度が10μg/mlになるようにメタノールに溶解し、メンプランフィルターで濾過した。この溶液を容量5mlの透明ガラスサンプル管に3mlずつ分注し、試料とした。一本はコントロールとして遮光し、もう一本は横置きにして光照射(蛍光灯:10001×時間)を行った。遮光条件下、逆相液体クロマトグラフ法により当該化合物のピーク面積を得、以下の式に従って残存率を求めた。

残存率(%)=光照射した試料のピーク面積/遮光した 試料のピーク面積×100

液体クロマトグラフ法での分析条件は以下の通りである。分析カラムは資生堂UG-120(4.6mmø×

250mm)を用い、移動層には0.01%トリフルオロ酢酸水溶液:メタノール=2:1(v/v)の溶液を用いた。検出はUV検出器を用い、検出波長は下記表4に示す通りとした。

【0555】光安定性試験の結果、2重結合化合物 [(E)-4-((3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エテニル) フェニル) アミノ)-2,2-ジエチルー4-オキソプチル酸(Ro24-5913)(特開平2-69468号)及び(E)-2-((3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル)エテニル)フェニルアミノ)-2-オキソエチル)安息香酸(特開平6-80654号)]の残存率がそれぞれ55.5%及び56.4%であったのに対し、3重結合化合物[実施例1、141、142及び187の化合物]の残存率はともに100%を示し、分解物の生成を認めなかった。溶液状態の光安定性試験結果(蛍光灯:1001x.3時間)を表4に示す。

[0556]

【表4】

| 被験物質 | 残存率(%) | 検出波長 |
|---------------------|--------|-----------|
| 実施例1の化合物 | 101.4 | 3 1 5 n m |
| 実施例141の化合物 | 100.4 | 253nm |
| 実施例142の化合物 | 99.9 | 3 1 2 n m |
| 実施例187の化合物 | 99.9 | 3 0 0 n m |
| 特開平2-69468号公報に | | |
| 記載の化合物 ^A | 55.5 | 240nm |
| 特開平6-80654号公報に | | |
| 記載の化合物 ^B | 56.4 | 2 3 5 n m |

A: (E) -4-((3-(2-(4-シクロブチル-2-チアゾリル) エテニル) フェニル) アミノ) -2, 2-ジエチル-4-オキソブチル酸 (Ro24-5913)

B: (E) -2- ((3-(2-(4-シクロプチル-2-チアゾリル) エテニ

ル)フェニルアミノ)-2-オキソエチル)安息香酸

【0557】 [試験例6] 安全性試験 Sprague-Dawley系ラットに、実施例1、 4、6、7、39、及び157の化合物を1日1回、2 50mg/kgを14日間経口投与したところ、いずれの化合物の投与においても、死亡例は認められなかった

フロントページの続き

| (51) Int. C1. 6 | 識別記号 | F I | |
|-----------------|------|----------------|-----|
| A 6 1 K 31/53 | ACD | A 6 1 K 31/53 | ACD |
| C 0 7 D 277/24 | | C O 7 D 277/24 | |
| 277/26 | | 277/26 | |
| 277/28 | | 277/28 | |
| 277/34 | | 277/34 | |
| 277/36 | | 277/36 | |
| | | | |

| 277/38 | | 277/38 | |
|--------|-------|--------|-------|
| 277/56 | | 277/56 | |
| 417/10 | 2 1 3 | 417/10 | 213 |
| | 2 5 5 | | 255 |
| | 2 5 7 | | 257 |
| | 261 | | 261 |
| | 263 | | 263 |
| | 271 | | 271 |
| | 3 1 1 | | 3 1 1 |
| 417/14 | 2 1 3 | 417/14 | 213 |
| | 2 3 9 | | 239 |
| | 257 | | 257 |
| 471/04 | 1 1 7 | 471/04 | 117A |

(72)発明者 小笠原 共実

東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第 一製薬株式会社東京研究開発センター内

(72)発明者 内藤 博之

東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第 一製薬株式会社東京研究開発センター内

(72)発明者 長谷川 雅司

東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第 一製薬株式会社東京研究開発センター内

(72) 発明者 春田 誠

東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第 一製薬株式会社東京研究開発センター内